รหัสโครงการ SUT7-715-56-24-48



การวิเคราะห์ซีโอดีด้วยวิธีการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส โดยใช้วัสดุกึ่งตัวนำเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (Analysis of COD by photoelectrocatalysis using semiconductors as catalyst)



ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผลงานวิจัยเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าโครงการวิจัยแต่เพียงผู้เดียว

รหัสโครงการ SUT7-715-56-24-48



รายงานการวิจัย

การวิเคราะห์ซีโอดีด้วยวิธีการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส ้โดยใช้วัสดุกึ่งตัวน<mark>ำเป็</mark>นตัวเร่งปฏิกิริยา (Analysis of COD by photoelectrocatalysis using semiconductors as catalyst)

#### คณะผู้วิจัย

หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศศวกรรมศาสตร์ มหาง... วาราสัญร่วมวิจัย อีนา จินด ยีสรบ่ มห<mark>าวิทยาลัยเทคโนโลยี</mark>สุรนารี

นางสาวอริยา จินดานันท์ นางสาวพิมพ์ชนก เหลือสูงเนิน

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 ผลงานวิจัยเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าโครงการวิจัยแต่เพียงผู้เดียว

ตุลาคม 2560

### กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ 2556-2557งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยการได้รับความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติที่ให้เงินสนับสนุนงานวิจัย เจ้าหน้าที่ศูนย์เครื่องมือและ วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) รวมถึงบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินงานวิจัย ได้แก่ คุณมานพ จรโคกกรวด คุณสินีนาฏ นอกกระโทก (เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ) ขอขอบคุณ คุณนารี กลิ่นกลาง (เจ้าหน้าที่บริหารงาน ทั่วไปประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) ที่ได้ให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือด้านการดำเนิน การวิจัยเป็นอย่างดี



#### บทคัดย่อ

้ค่าซีโอดีเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญที่ใช้ในการประเมินคุณภาพน้ำเสีย รวมไปถึงใช้ในการ ้ออกแบบ ติดตามควบคุม และประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งในการวิเคราะห์หา ้ค่าซีโอดีตามวิธีมาตรฐานไดโครเมตที่นิยมใช้กันในปัจจุบันนั้น จำเป็นต้องใช้สารเคมีหลายชนิด ซึ่งเป็น สารเคมีอันตราย มีความกัดกร่อนสูง มีราคาแพง และต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์นาน 3-5 ชั่วโมง เพื่อ ้ลดปัญหาของการวิเคราะห์หาค่าซีโอดีตามวิธีมาตรฐาน งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาการสังเคราะห์ ้วัสดุกึ่งตัวนำไทเทเนียมไดออกไซด์และซิงค์ออกไซด์เพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นตัวแทนในการนำมาใช้ หาค่าซีโอดีของน้ำเสียด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส จากการศึกษาคุณสมบัติของ ้ตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์ พบว่ากา<mark>รแ</mark>อโนไดซ์ในสารละลายแอมโมเนียมฟลูออไรด์ 0.30 โมลาร์ ผสมด้วยกลีเซอรอลและน้ำในอัตร<mark>าส่</mark>วน 60 : 40 โดยจ่ายความต่างศักย์แบ<sup>้</sup>บพัลส์ที่ 20 โวลต์ 5 นาที / -5 โวลต์ 5 วินาที เป็นเวลารวม 90 นาที ทำให้ได้ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีลักษณะ เป็นท่อขนาดนาโนเมตรที่มีการเรียงตัวอย่างสม่ำเสมอ สามารถตอบสนองต่อปฏิกิริยาเคมีแสงมากกว่า ้การแอโนไดซ์แบบจ่ายความต่างศักย์คงที่ สำห<mark>รั</mark>บตัวเร่<mark>ง</mark>ปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ พบว่า การแอโนไดซ์ใน ้สารละลายแอมโมเนียมฟลูออไรด์ 0.2 โมล<mark>าร์ โ</mark>ดยจ่าย<mark>ค</mark>วามต่างศักย์คงที่ 3 โวลต์ เป็นเวลา 60 นาที ้จะได้ซิงค์ออกไซด์ที่มีโครงสร้างแบบเฮ<mark>กซ</mark>ะโกนอลเ<mark>วอ</mark>ร์ตไซด์ ลักษณะสัณฐานวิทยาเป็นผลึก ทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนขนาดนาโนเม<mark>ตร</mark> มีการกระจาย<mark>ตัวอย่า</mark>งสม่ำเสมอ ซิงค์ออกไซด์นี้ให้ค่าความ หนาแน่นกระแสได้ถึง 357.049 มิ<mark>ลลิแ</mark>อมแปร์ต่อตาราง<mark>เซน</mark>ติเมตร สำหรับแสงยูวี และได้ถึง 201.333 มิลลิแอมแปร์ต่อตารางเซนติเมตร สำหรับแสงวิสิเบิล และตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์โดยการ ้เตรียมจากวิธีสปัตเตอริงบนโพลิไอมายด์ฟิล์มที่เคลือบด้วยทองแดง ที่เวลา 120 นาที มีลักษณะเป็นผลึก ้ขนาดนาโนเมตร และ 480 นา<mark>ที มี</mark>ลัก<mark>ษณะทร</mark>งกลมคล้าย<mark>ลำไยถูก</mark>คว้า<mark>นเม</mark>ล็ด ตัวเร่งปฏิกิริยาดังกล่าวถูก ้นำมาวัดซีโอดีและคำนวณค่าซ<mark>ีโอดี</mark>โดย<mark>อาศัยกฎกา</mark>รแยกสารด้วยไฟฟ้าขอ</mark>งฟาราเดย์ และทำการศึกษา เปรียบเทียบกับการวิเคราะห์<mark>หาค่าซีโอดีด้วยวิธีมา</mark>ตรฐานไดโครเมตแบบ Closed Reflux กลูโคสและ ้โพแทสเซียมไฮโดรเจนพลาเลตถูกใช้เป็<mark>นสารทดสอบการวัดค่าซีโอดี พบว</mark>่า ไทเทเนียมไดออกไซด์สามารถวัด ้ค่าซีโอดีได้ในช่วง 20-500 mg/L ที่สมการเส้นตรง y = 0.0896x + 18.5 และ R<sup>2</sup> = 0.9742 ส่วนซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการทั้งสองเมื่อนำไปวัดค่าซีโอดีพบว่าซิงค์ออกไซด์มีความไม่เสถียร และมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ซึ่งส่งผลการวัดค่าซีโอดี อย่างไรก็ตามจากการทดลองหาค่าซีโอดี ้จากกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสพบว่า ยังคงมีความถูกต้องแม่นยำค่อนข้างน้อย ดังนั้นจึงต้อง ้มีการวิจัยและศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาให้วิธีการหาค่าซีโอดีมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

#### Abstract

COD is an important parameter used for qualitative measurement of wastewater including following up and measuring quality of wastewater treatment system. Standard Dichromate is a presently widely used method for investigating COD. This method, however, requires chemicals which are sometimes hazardous, corrosive, expensive, taking longtime (3-5 hours) to analyze. In order to reduce those problems, this research focuses on a synthesis of semiconductor, Titanium dioxide and Zinc oxide for using as catalyst in photoelectrocatalysis for investigating COD of wastewater. By studying the properties of Titanium dioxide catalyst, there is an anodization of a 0.3 M ammonium fluoride solution mixed with glycerol and water by ratio 60:40. The method is run by applying voltage of 20 V for 5 minutes / -5 V for 5 minutes, and 90 minutes in total. Titanium dioxide is found with constantly nanotube, which can respond to photoelectrochemistry better than a constant voltage anodization. For zinc oxide catalyst, an anodization in 0.2 M ammonium fluoride with applying 3 V foe 60 minutes provides zinc oxide with hexagonal-wurtzite structure, morphology of a rhombic shaped crystal in nanometer scale, which being uniformly distributed. It has the photocurrent density up to 357.049 mA cm<sup> $^2$ </sup> for UV light and 201.333 mA cm<sup> $^2$ </sup> for visible light. Zinc oxide catalysts prepared from sputtering method on copper-clad polyimide film for 120 minutes has the crystal shaped in nanometer scale, and the one which was prepared for 480 minutes has the spherical space which a hollow inside. Those catalysts were used to measured COD and were calculated COD value by Faraday's law. And finally were compared with standard dichromate analysis by closed reflux method. Glucose and Potassium hydrogen phthalate were used as probe for COD measurement. It was found that titanium dioxide was suitable for COD measurement with the range of 20-500 mgL<sup>-1</sup> with a linear equation of y = 0.0896x + 18.5 and  $R^2 = 0.9742$ . Zinc oxides, which are synthesized by both methods, have instability and changeable physical characteristic, therefore, affect COD measurements. However, COD measurement by photoelectrocatalysis method has less accuracy so further research and studies are required for more reliability.

### สารบัญ

กิตติกรระ	มประกา	ศ		ึก
บทคัดย่อ	บภาษาไห	าย		ข
บทคัดย่อ	วภาษาอั <sup>.</sup>	งกฤษ <u></u>		ค
สารบัญ <u>.</u>				٩
สารบัญต	าาราง			សូ
สารบัญ <i>ร</i>	าาพ			จั
บทที่ 1	บทนำ			
	1.1	ความสำ	าคัญและที่มาของปัญห <mark>าที่ท</mark> ำการวิจัย	1
	1.2	วัตถุปร	ะสงค์ของโครงการวิจัย	3
	1.3	ขอบเขเ	ตของโครงการวิจัย	3
	1.4	ประโย	ชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
บทที่ 2 เ	ปริทัศน์	วรรณกร	รรมและงานวิจ <mark>ัยที่</mark> เกี่ยวข้อง	
	2.1	ซีโอดี <u>.</u>		4
		2.1.1	ความสำคัญของการวิเคราะห์ซีโอดี	4
		2.1.2	ทฤษฎีของซีโอดีและหลักการวิเคราะห์พื้นฐาน	4
		2.1.3	สาร <mark>รบ</mark> กวน <mark>ที่มีผลต่อการวิเคราะห์ซีโอดี</mark> ด้วย <mark>การ</mark> วิเคราะห์หาค่าซีโอดี	
			ตามวิธีมาตรฐาน	5
		2.1.4	สาร <mark>มาตรฐาน</mark> ซีโอด <u>ี</u>	7
		6	2.1.4.1 น้ำตาลกลูโคส ( <mark>D-glucose)</mark>	7
			2.1.4.2 โพแทสเซียมไฮโดรเจนพธาเลต	
			(Potassium hydrogen phthalate, KHP)	8
		2.1.5	คุณลักษณะน้ำเสียจากแหล่งต่าง ๆ	8
			2.1.5.1 น้ำเสียชุมชน	9
			2.1.5.2 น้ำเสียจากโรงพยาบาล	9
			2.1.5.3 น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	11
			2.1.5.4 น้ำเสียจากพื้นที่ทางการเกษตร	12
	2.2	กระบว	นการโฟโตคะตะไลซิส	12
		2.2.1	หลักการและกลไกของปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิส	12
			2.2.1.1 การเกาะหรือดูดติดผิวของตัวเร่งปฏิกิริยา	
			(Adsorption Process)	13
			2.2.1.2 การฉายแสง (Irradiation process)	13

หน้า

2.3	ตัวเร่งเ	ปฏิกิริยาและการสังเคร	ราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา	15
	2.3.1	การสังเคราะห์ตัวเร่ง	ปฏิกิริยาด้วยกระบวนการแอโนไดเซชัน	16
	2.3.2	การสังเคราะห์ตัวเร่ง		19
		2.3.2.1 วิธีดีซีสปัตเ	 ตอริง (DC Sputtering)	19
		2.3.2.2 วิธีอาร์เอฟส	สปัตเตอริง (RF Sputtering)	21
		2.3.2.3 ระบบเมกนี	ตรอนสปัตเตอริง (Magnetron Sputtering)	22
2.4	กระบว	นการโฟโตอิเล็กโตรคะ	ะตะ <mark>ไลซิ</mark> ส (Photoelectrocatalysis)	23
	2.4.1	ไฟฟ้าเคมี (Electroo	che <mark>mis</mark> try)	24
		2.4.1.1 เซลล์ไฟฟ้า	เคม <mark>ี (Elec</mark> trochemical cell)	24
		2.4.1.2 อิเล็กโตรไล	ซิ <mark>ส (Elec</mark> trolysis)	25
2.5	การวิเศ	าราะห์ซีโอดีด้วยกระบ	ว <mark>น</mark> การโฟ <mark>โ</mark> ตอิเล็กโตรคะตะไลซิส	27
2.6	งานวิจั	ยที่เกี่ยวข้อง		28
	2.6.1	การสังเคราะห์ตัว <mark>เร่</mark> ง	<mark>ปฏิกิริยาด้วยก</mark> ระบวนการแอโนไดซ์	28
	2.6.2	การสังเคราะ <mark>ห์ตัว</mark> เร่ง	ปฏิกิริยาด้วย <mark>กระบ</mark> วนการแอโนไดซ์แบบพัลส์	29
	2.6.3	การสังเครา <mark>ะห์ต</mark> ัวเร่ง	ปฏิกิริยาด้วยก <mark>ระบว</mark> นการสปัตเตอริง	30
	2.6.4	การวิเคร <mark>าะ</mark> ห์ซีโอดีโเ	ดยกระบวนการต่าง ๆ	32
3 วิธีดำ	แนินการวิส	จัย 🥖 📔		
3.1	ไทเทเน็	เียมไ <mark>ดออกไ</mark> ซด์		36
	3.1.1	การสังเคร <mark>าะห์ไทเทเเ</mark>	เียมได <mark>ออกไซด์โดยวิธีการแอ</mark> โนไดซ์แบบพัลส์	
	2	เป็นตัวเ <mark>ร่งปฏิกิริย</mark> า <u></u>	160	36
		3.1.1.1 การศึกษาผ	ลของเวลาที่ใช้ในการสังเคราะห์แผ่นไทเทเนียม	
		ที่มีต่อลักษ	ณะพื้นผิวของไทเทเนียมไดออกไซด์รูปท่อที่	
		เตรียมโดยก	าารแอโนไดซ์แบบพัลส์ <u></u>	39
		3.1.1.2 การหาค่าซีโ	้อดี	40
		3.1.1.2.1	การทดลองชุดควบคุม	41
		3.1.1.2.2	การวิเคราะห์หาค่าซีโอดีด้วยกระบวนการ	
			โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสโดยใช้ไทเทเนียมไดออก	ไซด์
			ที่สังเคราะห์ได้	43
		3.1.1.2.3	ตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำและความเสถียร	
			ของวิธีการหาค่าซี้โอดีด้วยกระบวนการ	
			โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส <u>.</u>	46
3.2	ซิงค์ออ	กไซด์		<u>5</u> 1
	3.2.1	สังเคราะห์ตัวเร่งปฏิ	กิริยาซิงค์ออกไซด์ด้วยกระบวนการแอโนไดเซชัน	<u>5</u> 1

บทที่

<ul> <li>3.2.2 สังเตราะห์ตัวเรงปฏิกรียาซิงค์ออกไซด์ดวยกระบวนการสปิตเตอริง</li></ul>				หน้า
<ul> <li>3.2.3 ศึกษาคุณลักษณะต่าง ๆ ของซึ่งค่ออกไซด์</li></ul>		3.2.2	สังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งค้ออกไซด์ด้วยกระบวนการสปัตเตอริ่ง	54
<ul> <li>3.2.4 การหาค่าซีโอดี</li></ul>		3.2.3	ศึกษาคุณลักษณะต่าง ๆ ของซิงค์ออกไซด์	57
<ul> <li>3.2.4.1 ศึกษาการตอบสนองต่อแสงของตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการแอโนไดเซชัน</li></ul>		3.2.4	การหาค่าซีโอดี	<u></u> 58
<ul> <li>พีสังเคราะห์ด้วยกระบวนการแอโนโดเซชัน</li></ul>			3.2.4.1 ศึกษาการตอบสนองต่อแสงของตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์	
<ul> <li>3.2.4.2 ทำการตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำและความเสถียรของวิธี การหาค่าซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสโดยใช้ ซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการแอโนไดเซชันเป็น ตัวเร่งปฏิกิริยา</li></ul>			ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการแอโนไดเซชัน <u></u>	58
การหาค่าซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสโดยใช้ ซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการแอโนโดเซชันเป็น ด้วเร่งปฏิกิริยา			3.2.4.2 ทำการตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำและความเสถียรของวิธี	
<ul> <li>ซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการแอโนไตเซชันเป็น ตัวเร่งปฏิกิริยา</li> <li>58</li> <li>3.2.4.3 ศึกษาการตอบสนองต่อแสงของตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการสปัตเตอริง</li> <li>64</li> <li>3.2.4.4 ทำการตรวจสอบความถูกต้องแม่นย้าและความเสถียรของวิธี การหาค่าซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส โดยไซ้ซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการสปัตเตอริง</li> <li>เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา</li> <li>65</li> <li>บทที่ 4 ผลการวิจัย</li> <li>4.1 ไทเทเนียมไดออกไซด์</li> <li>11 การสังเคราะห์โทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยกระบวนการแอโนไตเซชัน แบบพัลส์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา</li> <li>73</li> <li>4.1.1 การวิเคราะห์สัญานวิทยา</li> <li>73</li> <li>4.1.1 การวิเคราะห์สัญานวิทยา</li> <li>73</li> <li>4.1.1.2 การวิเคราะห์สัญานวิทยา</li> <li>73</li> <li>4.1.2 การวิเคราะห์การตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีแสง</li> <li>85</li> <li>4.1.2 การวิเคราะห์การตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีแสง</li> <li>86</li> <li>4.1.1.4 การวิเคราะห์ค่าดูดกลีนแสงของตัวเร่งปฏิกิริยา</li> <li>92</li> <li>4.1.2 การทดลองการหาค่าซิโอดีด้วยการบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส</li> <li>โดยใช้ชุดการทดลองที่ 1</li> <li>93</li> <li>4.1.2.2 การหาค่าซิโอดีด้วยการบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส</li> <li>1.2.2 การหาค่าซิโอดีด้วยการบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส</li> <li>4.1.2.3 การหาค่าซีโอดีด้วยการบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส</li> <li>4.1.2.1 การหาค่าซีโอดีด้วยการบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส</li> <li>4.1.2.1 การหาค่าซีโอดีด้วยการบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส</li> <li>4.1.2.1 การหาค่าซีโอดีด้วยการบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส</li> <li>4.1.2.1 การหาค่าซีโอดีด้วยการบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส</li> <li>4.1.2.1 การหาค่าซีโอดีด้วยการบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส</li> <li>4.1.2.2 การหาค่าซีโอดีด้วยการบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส</li> <li>4.1.2.3 การหาค่าซีโอดีด้วยการบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส</li> <li>4.1.2.3 การหาค่าซีโอดีด้วยการบานการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส</li> <li>4.1.2.4 สันต่องที่ออกไซด์อัยการบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส</li> <li>4.1.2.5 สารคะตะห์สิงคองที่ 3</li> <li>4.1.2.5 สารคาะห์สิงคองที่ 4</li> </ul>			การหาค่าซีโอดี <mark>ด้ว</mark> ยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสโดย	ู่ใช้
ตัวเร่งปฏิกิริยา       58         3.2.4.3 ศึกษาการตอบสนองต่อแสงของตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์       ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการสปัตเตอริง       64         3.2.4.4 ทำการตรวจสอบความถูกต้องแม่นย้าและความเสถียรของวิธี       การหาค่าชีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส       64         3.2.4.4 ทำการตรวจสอบความถูกต้องแม่นย้าและความเสถียรของวิธี       การหาค่าชีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส       64         1.2.4.4 ทำการตรวจสอบความถูกต้องแม่นย้าและความเสถียรของวิธี       การหาค่าชีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส       65         บทที่ 4 ผลการวิจัย       73       73       61       73         4.1.1       การสังเคราะห์เข้าเทเนียมไดออกไซด์ด้วยกระบวนการแอโนไตเซชัน       73         4.1.1       การสังเคราะห์มีเข้าเร่งปฏิกิริยา       73         4.1.1.1       การสังเคราะห์สัญานวิทยา       73         4.1.1.2       การวิเคราะห์กรามหนาของออกไซด์       85         4.1.1.2       การวิเคราะห์การตอบสนองปฏิกิริยาไฟท์เคมีแสง       86         4.1.1.4       การวิเคราะห์การตอบสนองปฏิกิริยาไฟท์เคมีแสง       86         4.1.1.4       การวิเคราะห์ก่าดูอกสีนแลงของตัวเร่งปฏิกิริยา       92         4.1.2       การทด่าชีโอดีด้วยการบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส       93         4.1.2.1       การทค่าชีโอดีด้วยการบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส       16ยใช้ชุดการทดลองที่ 2       96         4.1.2.2       การทค่าซีโอดีด้วยการบว			ซิงค์ออกไซด์ที่ส <mark>ังเ</mark> คราะห์ด้วยกระบวนการแอโนไดเซชันเป็น	
3.2.4.3 ศึกษาการตอบสนองต่อแสงของตัวเร่งปฏิกิริยาชิงค์ออกไซด์         ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการสปัตเตอริง			ตัวเร่งปฏิกิริย <mark>า</mark>	
<ul> <li>ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการสปัตเตอริง</li></ul>			3.2.4.3 ศึกษาการตอ <mark>บสนองต</mark> ่อแสงของตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์	
<ul> <li>3.2.4.4 ทำการตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำและความเสถียรของวิธี การหาค่าซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส โดยใช้ซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการสปัตเตอริง เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา</li></ul>			ที่สังเคราะห์ <mark>ด้</mark> วยกระ <mark>บ</mark> วนการสปัตเตอริง	<u></u> 64
การหาค่าซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส โดยใช้ซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการสปัตเตอริง เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา			3.2.4.4 ทำการต <mark>รวจ</mark> สอบควา <mark>ม</mark> ถูกต้องแม่นยำและความเสถียรของวิธี	
โดยใช้ซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการสปัตเตอริง เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา			การหาค <mark>่าซีโ</mark> อดีด้วยกร <mark>ะบว</mark> นการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส	
เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา			โดยใช้ซ <mark>ิ่งค์ออกไซด์ที่สังเคราะ</mark> ห์ด้วยกระบวนการสปัตเตอริง	
<b>บทที่ 4 ผลการวิจัย</b> 4.1 ไทเทเนียมไดออกไซด์			เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา	
<b>บทที่ 4 ผลการวิจัย</b> 4.1 ไทเทเนียมไดออกไซด์				
<ul> <li>4.1 ไทเทเนียมไดออกไซด์</li></ul>	บทที่ 4 ผลการ	ົວຈັຍ		
<ul> <li>4.1.1 การสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยกระบวนการแอโนไดเซซัน แบบพัลส์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา</li></ul>	4.1	ไทเทเเ	มียมได <mark>ออ</mark> กไซด์	73
<ul> <li>แบบพัลส์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา</li></ul>		4.1.1	กา <mark>รสังเค</mark> ราะห์ไทเทเนีย <mark>มไดออกไซด์ด้</mark> วยก <mark>ระบว</mark> นการแอโนไดเซซัน	
4.1.1.1 การวิเคราะห์สัญฐานวิทยา       73         4.1.1.2 การวิเคราะห์ความหนาของออกไซด์       85         4.1.1.3 การวิเคราะห์การตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีแสง       86         4.1.1.4 การวิเคราะห์หาโครงสร้างผลึกของออกไซด์       91         4.1.1.5 การวิเคราะห์หาโครงสร้างผลึกของออกไซด์       91         4.1.2 การทิดลองการหาค่าซิโอดีด้วยการบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส       92         4.1.2 การหาค่าซิโอดีด้วยการบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส       93         4.1.2.1 การหาค่าซิโอดีด้วยการบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส       93         4.1.2.2 การหาค่าซิโอดีด้วยการบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส       93         4.1.2.3 การหาค่าซิโอดีด้วยการบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส       94         1.1.2.1 การหาค่าซิโอดีด้วยการบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส       94         1.1.2.2 การหาค่าซิโอดีด้วยการบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส       94         1.1.2.3 การหาค่าซิโอดีด้วยการบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส       96         4.1.2.3 การหาค่าซิโอดีด้วยการบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส       100         4.2       ซิงค์ออกไซด์       100			แบบพัลส์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา	73
<ul> <li>4.1.1.2 การวิเคราะห์ความหนาของออกไซด์</li></ul>		1	4.1.1.1 การวิเคราะห์สัณฐานวิทยา	73
<ul> <li>4.1.1.3 การวิเคราะห์การตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีแสง</li></ul>			4.1.1.2 การวิเคราะห์ความหนาของออกไซด์	
<ul> <li>4.1.1.4 การวิเคราะห์หาโครงสร้างผลึกของออกไซด์</li></ul>			4.1.1.3 การวิเคราะห์การตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีแสง	
<ul> <li>4.1.1.5 การวิเคราะห์ค่าดูดกลื่นแสงของตัวเร่งปฏิกิริยา</li></ul>			<ol> <li>4.1.1.4 การวิเคราะห์หาโครงสร้างผลึกของออกไซด์</li> </ol>	
<ul> <li>4.1.2 การทดลองการหาค่าซีโอดีด้วยการบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส</li> <li>4.1.2.1 การหาค่าซีโอดีด้วยการบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส</li> <li>โดยใช้ชุดการทดลองที่ 1</li></ul>			4.1.1.5 การวิเคราะห์ค่าดุดกลืนแสงของตัวเร่งปฏิกิริยา	
<ul> <li>4.1.2.1 การหาค่าซีโอดีด้วยการบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส</li> <li>โดยใช้ชุดการทดลองที่ 193</li> <li>4.1.2.2 การหาค่าซีโอดีด้วยการบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส</li> <li>โดยใช้ชุดการทดลองที่ 296</li> <li>4.1.2.3 การหาค่าซีโอดีด้วยการบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส</li> <li>โดยใช้ชุดการทดลองที่ 3100</li> <li>4.2 ซิงค์ออกไซด์108</li> <li>4.2.1 สัมคราะห์ซิงค์ออกไซด์ด้วยกระบวนการแอโปไตเซชัน</li> </ul>		4.1.2	การทดลองการหาค่าซีโอดีด้วยการบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส	
โดยใช้ชุดการทดลองที่ 1			4.1.2.1 การหาค่าซีโอดีด้วยการบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส	
<ul> <li>4.1.2.2 การหาค่าซีโอดีด้วยการบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส</li> <li>โดยใช้ชุดการทดลองที่ 2</li></ul>			โดยใช้ชุดการทดลองที่ 1	93
โดยใช้ชุดการทดลองที่ 296 4.1.2.3 การหาค่าซีโอดีด้วยการบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส โดยใช้ชุดการทดลองที่ 3100 4.2 ซึ่งค์ออกไซด์108 4.2 สับคราะห์ซิงค์ออกไซด์ด้วยกระบวนการแอโปไดเซชัน 109			4.1.2.2 การหาค่าซีโอดีด้วยการบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส	
4.1.2.3 การหาค่าซีโอดีด้วยการบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส โดยใช้ชุดการทดลองที่ 3100 4.2 ซึงค์ออกไซด์108 4.2 สัมคราะห์ซิงค์ออกไซด์ด้วยกระบวนการแอโปไดเตชัน 109			โดยใช้ชุดการทดลองที่ 2	96
			4123 การหาค่าซีโอดีด้วยการบวบการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส	
4.2 ซึ่งค์ออกไซด์108 4.2 สังเคราะห์ซิงค์ออกไซด์ด้วยกระบานการแอโปไดเซชัน 109			โดยใช้ชุดการทดลองที่ 3	100
จังเออาจรระห์สิงค์ออกไซด์ด้วยกระบาบการแอโบไดเซชับ 100	4 2	ซิงค์ออ	กไซด์	108
	1.2	421	สังเคราะห์ซิงค์ออกไซด์ด้วยกระบาวบการแอโบไดเซซับ	109

		หน้า
4.2.2	ศึกษาคุณสมบัติของซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการ	
	แอโนไดเซชัน	111
	4.2.2.1 ศึกษาคุณลักษณะพื้นผิวของซิงค์ออกไซด์ด้วย FESEM	111
	4.2.2.2 วิเคราะห์ความขรุขระของซิงค์ออกไซด์ด้วย AFM	.117
	4.2.2.3 วิเคราะห์โครงสร้างผลึกหรือเฟสที่เกิดบนพื้นผิวของซิงค์ออกไซด์	•
	ด้วยเครื่อง XRD	_117
	4.2.2.4 วิเคราะห์การดูด <mark>กล</mark> ื่นแสงของซิงค์ออกไซด์	
	ด้วยเครื่อง UV- <mark>VIS</mark> spectrophotometer <u>.</u>	<u> 120 </u>
	4.2.2.5 วิเคราะห์อิเล <mark>็กตรอนที่</mark> เกิดขึ้นในรูปของความหนาแน่นกระแสไพ	ไฟ้า
	(Photocurr <mark>ent den</mark> sity) ของซิงค์ออกไซด์	
	ด้วยเครื่อง Potentiostat	<u> 121 </u>
	4.2.2.6 ศึกษากา <mark>รตอ</mark> บสนอง <mark>ต่อแ</mark> สงของตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์	_125
4.2.3	ศึกษาการใช้กระ <mark>บวน</mark> การโฟโต <mark>อิเล็ก</mark> โตรคะตะไลซิสในการวัดค่าซีโอดี	
	(COD <sub>PEC</sub> ) โด <mark>ยใช้</mark> ซิงค์อ <mark>อกไซ</mark> ด์ที่สังเ <mark>ครา</mark> ะห์จากกระบวนการแอโนไดซเซชั	ัน
	เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา	.126
	4.2.3.1 <mark>วัด</mark> ค่าซีโอดีด้วยเครื่องวัดที่สร้างขึ้น	126
	4.2.3.2 วัดค่าซีโอดีด้วยเครื่องโพเทนชิโอสแตท (Potentiostat)	<u>.</u> 131
4.2.4	สังเ <mark>คราะ</mark> ห์ซิ <mark>งค์ออกไซด์ด้วยวิธีการสปัต</mark> เตอริ <mark>ง (s</mark> puttering)	
	บน <mark>พลาส</mark> ติกพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (polyethylene terephthalate,	,
	PET) <mark>ที่ผ่านการเคลือบด้วยเงิน (Ag) และอินเ</mark> ดียมทินออกไซด์ (Indium	
C	Tin Oxide, ITO)	_132
4.2.5	ศึกษาคุณสมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการ	
	สปัตเตอริง (sputtering) บนพลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต	
	(polyethylene terephthalate, PET) ที่ผ่านการเคลือบด้วยเงิน (Ag)	
	และอินเดียมทินออกไซด์ (Indium Tin Oxide, ITO)	_135
	4.2.5.1 วิเคราะห์โครงสร้างผลึกหรือเฟสที่เกิดบนพื้นผิวของซิงค์ออกไซด์	-
	ด้วยเครื่อง XRD	<u>135</u>
	4.2.5.2 วิเคราะห์ชนิดและสถานะทางเคมีของธาตุที่เป็นองค์ประกอบ	
	ที่เกิดบนพื้นผิวของซิงค์ออกไซด์ด้วยเครื่อง XPS	136
4.2.6	สังเคราะห์ซิงค์ออกไซด์ด้วยวิธีการสปัตเตอริง (sputtering) บน	
	โพลิไอมายด์ฟิล์มทีเคลือบด้วยทองแดง (Copper-clad polyimide film,	
	Cu-clad PI film)	137

4.2.7	ศึกษาคุเ	ณสมบัติของต้	<i>้</i> วเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วย	
	วิธีการส	ปัตเตอริง (sp	uttering) บนโพลิไอมายด์ฟิล์มที่เคลือบด้วยทองแด	٩
	(Coppe	r-clad polyi	mide film, Cu-clad PI film)	_138
	4.2.7.1	ศึกษาคุณลัก	ษณะพื้นผิวของซิงค์ออกไซด์ด้วยเครื่อง FESEM	_138
	4.2.7.2	ศึกษาความเ	หนาของซิงค์ออกไซด์ด้วยเครื่อง Optical profiler <u>.</u>	140
	4.2.7.3	วิเคราะห์การ	เดูดกลืนแสงของซิงค์ออกไซด์	
		ด้วยเครื่อง L	IV- <mark>VIS</mark> spectrophotometer	143
	4.2.7.4	ศึกษาการตอ	วบส <mark>นอ</mark> งต่อแสงของตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์	<u> 1</u> 43
4.2.8	ศึกษากา	ารใช้กระบวน	ก <mark>ารโพ</mark> โตอิเล็กโตรคะตะไลซิสในการวัดค่าซีโอดี	
	(COD <sub>PE</sub>	<sub>c</sub> ) โดยใช้ซิงค์	<mark>ออกไซด์ท</mark> ี่สังเคราะห์จากกระบวนการสปัตเตอริง	
	เป็นตัวเ	ร่งปฏิกิริยา	<u>/                                     </u>	146
	4.2.8.1	ทดสอบควา	มเสถียรข <mark>อ</mark> งซิงค์ออกไซด์โดยการวัดซ้ำของสารละล	าย
		อิเล็กโต <mark>รไล</mark> ต	ก์ด้วยเครื่อ <mark>งโพ</mark> เทนซิโอสแตท (Potentiostat)	146
	4.2.8.2	วัดค่ <mark>าซีโ</mark> อดีด้	้วยเครื่องม <b>ัลติมิเต</b> อร์ (multimeter)	_147
		4.2 <mark>.8.2</mark> .1	ทดลองเบื้องต้ <mark>นใน</mark> การวัดซีโอดีด้วย	
			กระบวนการโฟโตอ <mark>ิเ</mark> ล็กโตรคะตะไลซิส	_148
		4.2.8.2.2	เปรียบเทียบขั้วไฟฟ้าร่วม	_150
		4.2.8.2.3	ต <mark>รวจสอบความถ</mark> ูกต้อ <mark>งแม่</mark> นยำและความเสถียร	
			ของวิธีการหาค่าซีโอดีด้วยกระบวนการ	
			โฟโตอิเล็กโตรคะ <mark>ตะไลซิส</mark> โดยใช้ซิงค์ออกไซด์	
C			<mark>ที่สปัตเตอริง 120 นา</mark> ที เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา	_151
	5.	4.2.8.2.4	ตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำและความเสถียร	
	107	1517-	ของวิธีการหาค่าซีโอดีด้วยกระบวนการ	
		BPIO	โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสโดยใช้ซิงค์ออกไซด์	
			ที่สปัตเตอริง 480 นาที เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา	162
		4.2.8.2.5	เปรียบเทียบภาพถ่าย FESEM ของซิ้งค์ออกไซด์	
			ก่อนและหลังวัดซีโอด <u>ี</u>	_164
		4.2.8.2.6	วิเคราะห์หาซิงค์และทองแดงในน้ำเสียที่ผ่านการวั	้ด
			ค่าซีโอดีด้วยด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไล	าซิส
			(COD <sub>PEC</sub> ) ด้วยเครื่อง ICP-MS	_166

### หน้า

บทที่ 5 สรุปผล	การวิจัยเ	เละข้อเสนอแนะ	
5.1	ไทเทเนี	ยมไดออกไซด์	_167
	5.1.1	สรุปผลการศึกษา	_167
		5.1.1.1 ผลการศึกษาการสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์รูปท่อ	
		ด้วยกระบวนการแอโนไดเซซันแบบพัลส์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา	167
		5.1.1.2 ผลการศึกษาการใช้กระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส	
		ในการวัดค่าซีโอดี <mark>โด</mark> ยใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์รูปท่อที่เตรียมด้วย	
		กระบวนแอโนไ <mark>ดเซ</mark> ซันแบบพัลส์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา	168
	5.1.2	ข้อเสนอแนะ	168
5.2	ซิงค์ออเ	าไซด์	<u> 169 </u>
	5.2.1	สรุปผลการศึกษา	_169
		5.2.1.1 ผลการศึ <mark>กษา</mark> การสังเค <mark>ราะ</mark> ห์ซิงค์ออกไซด์	
		ด้วยกระ <mark>บว</mark> นการแอโน <mark>ไดเ</mark> ซชัน	
		5.2.1.2 ผลก <mark>ารศึกษาการใช้กระบวนก</mark> ารโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส	
		ใน <mark>การ</mark> วัดค่าซีโ <mark>อดีโ</mark> ดยใช้ซึง <mark>ค์ออ</mark> กไซด์ที่สังเคราะห์	
		จ <mark>า</mark> กกระบวนการแอโนไดซเซชัน <mark>เป็</mark> นตัวเร่งปฏิกิริยา <u></u>	_170
		5.2.1. <mark>3 ผลการศึกษาการสังเคราะห์ซิง</mark> ค์อ <mark>อกไ</mark> ซด์	
		🥏 ด้วยกระบวนการสปัตเตอริง	171
		5.2 <mark>.1.4</mark> ผลการศึกษาการใช้กระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส	
		ในการวัดค่าซีโอดีโดยใช้ซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์	
	C	<mark>จากกระบวนการสปัตเตอริงเป็นตัว</mark> เร่งปฏิกิริยา	_172
	5.2.2	ข้อเสนอแนะ	174
		้ <sup>อ</sup> กยาวัฒนอโมโลยีสีรี	
บรรณานุกรม			<u>175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 </u>
ภาคผนวก			
ภาคผน	วก ก	รายละเอียดเครื่องมือวิเคราะห์คุณสมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยา	_182
ภาคผน	วก ข	ผลการทดลองเบื้องต้น <u></u>	<u>1</u> 92
ภาคผน	วก ค	การปรับวัตถุประสงค์และขอบเขตงานวิจัย <u>.</u>	_202
ประวัติผู้วิจัย <u></u>			.206

# สารบัญตาราง

		หน้า
ตารางที่ 2.1	ลักษณะน้ำเสียตามกิจกรรมต่าง ๆ	10
ตารางที่ 2.2	ลักษณะน้ำเสียทั่วไปของโรงพยาบาล	11
ตารางที่ 2.3	ลักษณะน้ำเสียจากอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ	11
ตารางที่ 2.4	ลักษณะน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากฟาร์มสุกร ประเภท ค จำแนกตามประเภทสุกรที่เลี้ยง <u>.</u>	12
ตารางที่ 3.1	สภาวะทดลองเพื่อศึกษาผลของเวลาที่ใช้ในการสังเคราะห์แผ่นไทเทเนียม	
	ที่มีต่อลักษณะพื้นผิวของไทเทเนียมไดออกไซด์รูปท่อที่เตรียมโดยการแอโนไดซ์	
	แบบพัลส์	39
ตารางที่ 3.2	สภาวะทดลองเพื่อศึกษาประเภท <mark>ขอ</mark> งสารอิเล็กโทรไลต์ที่เหมาะสม	
	ต่อกระบวนการโฟโตอิเล็กโตร <mark>คะต</mark> ะไลซิส	47
ตารางที่ 3.3	สภาวะทดลองเพื่อศึกษาความต่ <mark>างศักย์ที่</mark> เหมาะสมต่อกระบวนการ	
	โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส	47
ตารางที่ 3.4	สภาวะทดลองเพื่อศึกษาป <mark>ระเ</mark> ภทของ <mark>ขั้วไฟ</mark> ฟ้าร่วมที่ส่งผลต่อกระบวนการโฟโต	ອີເລົົກ
	โตรคะตะไลซิส	48
ตารางที่ 3.5	สภาวะทดลองเพื่อศึกษา <mark>ค</mark> วามต่างศักย์ที่เหม <mark>าะส</mark> มของชุดการทดลองที่ 3	
	ส่งผลต่อกระบวนกา <mark>รโฟโ</mark> ตอิเล็กโตร <mark>คะตะไลซิส</mark>	48
ตารางที่ 3.6	สารละลายมาตรฐ <mark>านกลู</mark> โคสความเข้มข้นต่าง ๆ ที่ <mark>ใช้</mark> เป็นตัวแทนน้ำเสีย	
	ในการหาค่าซีโ <mark>อดี</mark> ด้วย <mark>กระบวนการโฟโตอิเล็กโต</mark> รค <mark>ะตะ</mark> ไลซิส	49
ตารางที่ 3.7	สารละลายม <mark>าตร</mark> ฐาน <mark>กลูโคส</mark> ความเข้มข้นต่าง ๆ ที่ใช้เป็นตัวแทนน้ำเสีย	
	ในการหาค่า <mark>ซีโอดี</mark> ด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรค <mark>ะตะไ</mark> ลซิส	49
ตารางที่ 3.8	สารละลายม <mark>าตรฐานโพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลท (KH</mark> P) ความเข้มข้นต่าง ๆ ร	ที่ใช้
	เป็นตัวแทนน้ำเสี <mark>ยในการหาค่าซีโอดีด้วยกระบวนกา</mark> รโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส <u></u>	50
ตารางที่ 3.9	สภาวะการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ด้วยกระบวนการแอโนไดเซชัน	52
ารางที่ 3.10	สภาวะการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ด้วยกระบวนการสปัตเตอริง	57
ตารางที่ 3.11	สภาวะการทดลองหาค่าซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส	
	ที่ซีโอดีความเข้มข้นต่าง ๆ	61
ตารางที่ 3.12	สภาวะการทดลองหาค่าซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส	
	ที่ใช้สารอิเล็กโทรไลต์โซเดียมซัลเฟตที่ความเข้มข้นต่าง ๆ	63
ตารางที่ 3.13	สภาวะการทดลองหาค่าซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส	
	ที่จ่ายความต่างศักย์ต่างกัน	63
ตารางที่ 3.14	สภาวะการทดลองหาค่าซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส	
	ที่ระยะเวลาต่างกัน	64
ตารางที่ 3.15	สภาวะการทดลองการวัดซีโอดีในเบื้องต้นโดยใช้ซิงค์ออกไซด์	
	ที่ผ่านการสปัตเตอริงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา	67
ตารางที่ 3.16	สภาวะการทดลองการใช้ขั้วฟ้าร่วมต่างชนิด	67

# สารบัญตาราง (ต่อ)

		หน้า
ตารางที่ 3.17	สภาวะการทดลองหาค่าซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส	
	ที่ซีโอดีความเข้มข้นต่าง ๆ	68
ตารางที่ 3.18	สภาวะการทดลองหาค่าซีโอดีของสารซีโอดีทางทฤษฎีต่างชนิดกัน	69
ตารางที่ 3.19	สภาวะการศึกษาการตอบสนองของซิงค์ออกไซด์ที่ความต่างศักย์ต่าง ๆ	70
ตารางที่ 3.20	สภาวะการทดลองเพื่อตรวจสอบปัจจัยการเคลื่อนย้ายตำแหน่งอุปกรณ์	
	ในการวัดซีโอดี	71
ตารางที่ 3.21	สภาวะการทดลองหาค่าซีโอดีด้วย <mark>กร</mark> ะบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส	
	ที่ซีโอดีความเข้มข้นต่าง ๆ	72
ตารางที่ 4.1	สภาวะการทดลองที่จะเปรียบเ <mark>ทียบลัก</mark> ษณะสัณฐานวิทยา	
	ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอ <mark>นแบบส่อ</mark> งกราด (FE-SEM)	75
ตารางที่ 4.2	ลักษณะสัณฐานของไทเทเนียม <mark>ไ</mark> ดออกไ <mark>ซ</mark> ด์ที่ทำการสังเคราะห์	
	ด้วยกระบวนการแอโนไดเซซั <mark>น</mark> แบบพัล <mark>ส์ขอ</mark> งสภาวะการทดลองที่ 1	76
ตารางที่ 4.3	ลักษณะสัณฐานของไทเทเ <mark>นีย</mark> มไดออกไซ <mark>ด์ที่</mark> ทำการสังเคราะห์	
	ด้วยกระบวนการแอโนได <mark>เ</mark> ซซันแบบพัลส์ขอ <mark>งสภ</mark> าวะการทดลองที่ 2	77
ตารางที่ 4.4	ลักษณะสัณฐานของไ <mark>ทเท</mark> เนียมไดออกไซด์ที่ท <mark>ำกา</mark> รสังเคราะห์	
	ด้วยกระบวนการแ <mark>อ</mark> โนไดเซซันแบบพัลส์ของสภาว <mark>ะ</mark> การทดลองที่ 3	
ตารางที่ 4.5	ลักษณะสัณฐานข <mark>อ</mark> งไท <mark>เทเนียมไดออกไซด์ที่ท</mark> ำการสังเคราะห์	
	ด้วยกระบวน <mark>การแอโนไดเซซันแบบพัลส์ของสภ</mark> าวะการทุดลองที่ 4	79
ตารางที่ 4.6	เปรียบเทียบ <mark>ลักษณะไทเทเนียมได</mark> ออกไซด์ที่เกิดขึ้นใ <mark>นแต่</mark> ละสภาวะการสังเคราะ	ห <u>์ 8</u> 1
ตารางที่ 4.7	สภาวะการท <mark>ดลองลดระยะเว</mark> ลาก <mark>ารสังเคราะห์ทั้งหมด</mark>	82
ตารางที่ 4.8	ลักษณะสัณฐาน <mark>ของไทเทเนียมไดอ</mark> อกไซ <mark>ด์ที่ทำการท</mark> ดลอง 🏹	
	ลดระยะเวลาการสังเคราะห์ทั้งหมด	
ตารางที่ 4.9	ค่า Photocurrent density ของแผ่น TiO <sub>2</sub> ที่ผ่านการแอโนไดซ์แบบพัลส์และ	
	แบบการจ่ายความต่างศักย์คงที่ ใช้ระยะเวลาการสังเคราะห์ทั้งหมด 3 ชั่วโมง <u></u>	
ตารางที่ 4.10	ค่า Photocurrent density ของแผ่น TiO <sub>2</sub> ที่ผ่านการแอโนไดซ์แบบพัลส์	89
ตารางที่ 4.11	ค่า Photocurrent density ที่สภาวะการสังเคราะห์ 20 โวลต์ 5 นาที / -5 โวลต์ 5	วินาที
	ระยะเวลาการสังเคราะห์ทั้งหมด 1.5 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับ 3 ชั่วโมง	91
ตารางที่ 4.12	ค่าซีโอดีจากกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส	
	เปรียบเทียบกับค่าซีโอดีทฤษฎี	104
ตารางที่ 4.13	เปรียบเทียบค่าพื้นที่ใต้กราฟ	
	จากสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไฮโดรเจนพลาเลต	105
ตารางที่ 4.14	ลักษณะสัณฐานวิทยาของซิงค์ออกไซด์ที่สภาวะการแอโนไดซ์ต่าง ๆ	116
ตางรางที่ 4.15	คุณลักษณะพื้นผิวออกไซด์ด้วย FESEM	140
ตารางที่ 4.16	ความหนาของซิงค์ออกไซด์เมื่อสปัตเตอริงด้วยระยะเวลาต่าง ๆ	140

# สารบัญตาราง (ต่อ)

		หน้า
ตารางที่ 4.17	พื้นที่ใต้กราฟ (Q) และค่าซีโอดีที่วัดได้จากกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส_	150
ตารางที่ 4.18	ค่าซีโอดีที่วัดจากความเข้มข้นต่ำไปสูงและสูงไปต่ำ	152
ตารางที่ 4.19	แสดงค่าซีโอดีที่ได้จากกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสจากการวัดซ้ำ	154
ตารางที่ 4.20	แสดงลักษณะทางกายภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาที่เปลี่ยนแปลงไป	
	เมื่อผ่านการใช้ซ้ำ	<u>.</u> 154
ตารางที่ 4.21	แสดงค่าซีโอดีของกลูโคสที่ได้จากกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส	155
ตารางที่ 4.22	แสดงค่าซีโอดีของ KHP ที่ได้จาก <mark>กร</mark> ะบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส	<u>   157                                 </u>
ตารางที่ 4.23	พื้นที่ใต้กราฟของการวัดซีโอดีที่ค <mark>วา</mark> มเข้มข้นต่าง ๆ	163
ตารางที่ 4.24	พื้นที่ใต้กราฟของการวัดซีโอดีที <mark>่ความ</mark> เข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร <u></u>	164
ตารางที่ 4.25	ความเข้มข้นของซิงค์และทองแ <mark>ด</mark> งในน้ <mark>ำ</mark> ตัวอย่างที่ผ่านการวัดซีโอดี	166
ตารางที่ ข.1	แสดงค่าซีโอดีที่วิเคราะห์ด้วยวิ <mark>ธ</mark> ีมาตร <mark>ฐา</mark> นไดโครเมต (COD <sub>cr</sub> )	
	ແບບ Closed Reflux (n=5)	193
ตารางที่ ข.2.1	ความส่องสว่างของแสงก่อ <mark>นติ</mark> ดพั <mark>ดลมระบาย</mark> อากาศ	195
ตารางที่ ข.2.2	ค่าความส่องสว่างของ <mark>แสง</mark> ก่อนและหลังติดพัดลมระบายอากาศ	195
ตารางที่ ข.3	ข้อมูลพื้นที่ใต้กราฟ (Q) ที่ความต่างศักย์ใด ๆ	196
ตารางที่ ข.4	การทดสอบทางสถ <mark>ิติเปรียบเทียบผลต่าง</mark> ค่าเฉลี่ยข <mark>อ</mark> งการวัด Q	
	ด้วยซิงค์ออกไซด์ 2 แผ่น	199

ะ ราว<sub>ักยาลัยเทคโนโลยีสุรมาร</sub>

# สารบัญรูปภาพ

		หน้า
รูปที่ 2.1	ค่าช่องว่างของพลังงานของสารกึ่งตัวนำชนิดต่าง ๆ ที่พีเอช 1	14
รูปที่ 2.2	การเกิดอิเล็กตรอน (e <sup>-</sup> ) และที่ว่างของอิเล็กตรอน (hole: h+)ในปฏิกิริยา	
-	โฟโตคะตะไลซิส	14
รูปที่ 2.3	เซลล์โครงสร้างหกเหลี่ยมของชั้นอะลูมิเนียมออกไซด์	16
รูปที่ 2.4	ไดอะแกรมการพัฒนาของไทเทเนียมรู <sup>้</sup> ปท่อขนาดนาโน	17
รูปที่ 2.5	สัญญาณพัลส์	
รูปที่ 2.6	ส่วนประกอบของสัญญาณพัลส์	18
รูปที่ 2.7	ระบบดีซีสปัตเตอริง	20
รูปที่ 2.8	ระบบอาร์เอฟสปัตเตอริง	22
รูปที่ 2.9	ระบบแมกนีตรอนสปัตเตอริง	23
รูปที่ 2.10	กระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะ <mark>ต</mark> ะไลซิส <mark>.</mark>	23
รูปที่ 2.11	เซลล์ไฟฟ้าเคมีทองแดงแล <mark>ะสัง</mark> กะสี	24
รูปที่ 2.12	เซลล์ไฟฟ้าแบบ 3 ขั้ว (th <mark>ree</mark> -electrod <mark>e c</mark> ell <u>)</u>	
รูปที่ 3.1	ขั้นตอนการศึกษาวิจัย	
รูปที่ 3.2	การเตรียมแผ่นไทเท <mark>เนีย</mark> มที่จะใช้ในการสังเค <mark>ราะ</mark> ห์ไทเทเนียมไดออกไซด์	37
รูปที่ 3.3	ลักษณะการสังเคร <mark>าะห์</mark> ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยกระบว <mark>น</mark> การแอนโนไดเซชัน	38
รูปที่ 3.4	วิธีการสังเคราะ <mark>ห์ไ</mark> ทเท <mark>เนียมไดออกไซด์ด้วยกร</mark> ะบวน <mark>กา</mark> รแอโนไดซ์	38
รูปที่ 3.5	ลักษณะการ <mark>แอโ</mark> นไดซ์แบบพัลส์	
รูปที่ 3.6	โครงสร้างขอ <mark>งกลู</mark> โคสและโพแทสเซียมไฮโดรเจนพลาเลต	
รูปที่ 3.7	วิธีวิเคราะห์ห <mark>าค่าซีโอดีด้วยวิ</mark> ธีมา <mark>ตรฐานไดโครเมต</mark>	
รูปที่ 3.8	ถังปฏิกรณ์ชุดการท <mark>ดลองที่ 1</mark>	43
รูปที่ 3.9	เครื่องมือที่ใช้จ่ายค่าความต่างศักย์แล <mark>ะ</mark> วัดค่ากระแสไฟฟ้าที่สร้างขึ้น	44
รูปที่ 3.10	ถังปฏิกรณ์ชุดการทดลองที่ 2	
รูปที่ 3.11	เครื่องดิจิตอล มัลติมิเตอร์ รุ่น keysight 34465a ที่ใช้ในการวัดกระแส	46
รูปที่ 3.12	ลักษณะการทดลองการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์	
รูปที่ 3.13	วิธีการสังเคราะห์ซิงค์ออกไซด์ด้วยกระบวนการแอโนไดเซชัน	
รูปที่ 3.14 <sup>1</sup>	วิธีการสังเคราะห์ซิงค์ออกไซด์ด้วยกระบวนการสปัตเตอริง	55
รูปที่ 3.14 <sup>2</sup>	วิธีการสังเคราะห์ซิงค์ออกไซด์ด้วยกระบวนการสปัตเตอริง	
รูปที่ 3.15	ลักษณะการทดลองการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์	
0	ด้วยกระบวนการสปัตเตอริง	
รูปที่ 3.16	ลักษณะการทดลองตอบสนองต่อแสงของตัวเร่งปฏิกิริยา	
รูปที่ 3.17	การหาค่าซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส	
- รูปที่ 3.18	เครื่องวัดซีโอดีที่สร้างขึ้น	60
รูปที่ 3.19	ถังปฏิกรณ์สำหรับวัดซีโอดี	

		หน้า
รูปที่ 3.20	เครื่องมัลติมิเตอร์รุ่น keysight 34465a	64
รูปที่ 3.21	ลักษณะการทดลองการวัดซีโอดีโดยใช้เซลล์ไฟฟ้า 3 ขั้วต่อเข้ากับเครื่องมัลติมิเตอ	ວร <u>์ 6</u> 6
รูปที่ 4.1	ภาพถ่าย FESEM กำลังขยาย 50,000 เท่าของแผ่น TiO <sub>2</sub> ที่ผ่านการแอโนไดซ์	
-	ที่ความต่างศักย์ 20 โวลต์(แบบต่อเนื่อง) เป็นระยะเวลา 3 ชั่วโมง	74
รูปที่ 4.2	ภาพถ่าย FIB-FESEM แสดงความหนาชั้นออกไซด์ของแผ่น TiO <sub>2</sub>	
	ที่ผ่านการแอโนไดซ์	85
รูปที่ 4.3	ภาพถ่าย FIB-FESEM แสดงความหนาชั้นออกไซด์ของแผ่น TiO <sub>2</sub>	
•	ที่ผ่านการแอโนไดซ์ตามระยะเวล <mark>าท</mark> ี่ใช้การสังเคราะห์ทั้งหมด	86
รูปที่ 4.4	กราฟ Photocurrent density <mark>ของ</mark> แผ่น TiO <sub>2</sub> ที่ผ่านการแอโนไดซ์แบบพัลส์แล	ee
0	แบบการจ่ายความต่างศักย์คง <mark>ที่ ใช้ระย</mark> ะเวลาการสังเคราะห์ทั้งหมด 3 ชั่วโมง <u></u>	<u></u> 87
ปที่ 4.5	กราฟ Photocurrent densit <mark>y</mark> ของแ <mark>ผ่</mark> น TiO <sub>2</sub> ที่ผ่านการแอโนไดซ์แบบพัลส์	
	ทั้งหมด	
รูปที่ 4.6	กราฟ Photocurrent de <mark>nsit</mark> y ของแผ่ <mark>น T</mark> iO <sub>2</sub> ที่ผ่านการแอโนไดซ์แบบพัลส์	
0	โดยเปรียบเทียบระยะเวล <mark>ากา</mark> รสังเคราะห์ทั้ <mark>ง</mark> หมด 0.5 1 1.5 และ 3 ชั่วโมง	90
รูปที่ 4.7	กราฟ Photocurrent <mark>den</mark> sity ที่สภาวะการสังเ <mark>ครา</mark> ะห์ 20 โวลต์ 5 นาที / -5 โวลต์ 5	วินาที
	ระยะเวลาการสังเค <mark>ราะห์ทั้งหมด 1.5 ชั่วโมง เปรีย</mark> บเทียบกับ 3 ชั่วโมง <u></u>	
รูปที่ 4.8	วิเคราะห์โครงสร้างผลึกของออกไซด์ที่เกินบนพื้นผิวของแผ่น TiO2	
	ด้วยเครื่อง XRD	<u></u> 92
รูปที่ 4.9	การดูดกลืน <mark>แสงข</mark> องตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยเครื่อง UV/VIS Spectrophotometer	
รูปที่ 4.10	การต <sup>้</sup> อบสนอ <mark>งของกระแสไฟฟ้าจากกระบวนการโฟโตอิเ</mark> ล็กโตรคะตะไลซิส	
	ของชุดการทดลองที่ 1 (ครั้งที่1)	94
รูปที่ 4.11	การต <sup>้</sup> อบสนองของกร <mark>ะแสไฟฟ้าจากกระบวนกา</mark> รโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส	
0	ของชุดการทดลองที่ 1 (ครั้งที่2)	95
รูปที่ 4.12	การต <sup>่</sup> อบสนองของกระแสไฟฟ้าจากกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส	
-	ของชุดการทดลองที่ 1 (ครั้งที่3)	96
รูปที่ 4.13	การต <sup>้</sup> อบสนองของกระแสไฟฟ้าที่เปรียบเทียบประเภทของสารละลายอิเล็กโทรไ	ิลต์
-	ของชุดการทดลองที่ 2	<u>97</u>
รูปที่ 4.14	เปรียบเทียบการตอบสนองของกระแสไฟฟ้าที่ความต่างศักย์ 0.5 โวลต์และ 2.0	โวลต์
-	ที่สารละลายอิเล็กโทรไลต์โซเดียมซัลเฟต 0.1 โมลาร์ ของชุดการทดลองที่ 2	
รูปที่ 4.15	เปรียบเทียบการตอบสนองของกระแสไฟฟ้าที่ความต่างศักย์ 0.5 โวลต์และ 2.0	โวลต์
-	ที่สารละลายอิเล็กโทรไลต์โซเดียมซัลเฟต 1.0 โมลาร์ ของชุดการทดลองที่ 2	99
รูปที่ 4.16	การตอบสนองของกระแสไฟฟ้าที่เปรียบเทียบประเภทของขั้วไฟฟ้าร่วม	100
รูปที่ 4.17	เปรียบเทียบการตอบสนองของกระแสไฟฟ้าที่ความต่างศักย์ต่าง ๆ	
	ของชุดการทดลองที่ 2	101

ମ୍ଭ

		หน้า
รูปที่ 4.18	การตอบสนองของกระแสไฟฟ้าจากกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส	
	ของชุดการทดลองที่ 3 (ครั้งที่ 1)	102
รูปที่ 4.19	การตอบสนองของกระแสไฟฟ้าจากกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส	
	ของชุดการทดลองที่ 3 (ครั้งที่ 2)	103
รูปที่ 4.20	ความสัมพันธ์ระหว่างค่าซีโอดีทางทฤษฎีและค่าซีโอดี	
	จากกระบวนการโฟโตอิเล็กโตร-คะตะไลซิสของชุดการทดลองที่ 3	104
รูปที่ 4.21	การตอบสนองของกระแสไฟฟ้าจ <mark>าก</mark> แบลงค์ โดยไม่มีการคีบสายไฟใหม่	105
รูปที่ 4.22	กราฟมาตรฐานแสดงความสัมพัน <mark>ธ์ร</mark> ะหว่างค่าพื้นที่ใต้กราฟ (Q <sub>net</sub> )	
	กับค่าซีโอดีทางทฤษฎีของชุดก <mark>ารท</mark> ดลองที่ 3 (ครั้งที่ 1	106
รูปที่ 4.23	กราฟมาตรฐานแสดงความสัมพ <mark>ันธ์ระห</mark> ว่างค่าพื้นที่ใต้กราฟ (Q <sub>net</sub> )	
	กับค่าซีโอดีทางทฤษฎีของชุด <mark>ก</mark> ารทดล <mark>อ</mark> งที่ 3 (ครั้งที่ 2)	107
รูปที่ 4.24	กราฟมาตรฐานแสดงความ <mark>สัม</mark> พันธ์ระห <mark>ว่าง</mark> ค่าพื้นที่ใต้กราฟ (Q <sub>net</sub> )	
	กับค่าซีโอดีทางทฤษฎีขอ <mark>งชุด</mark> การทดลอ <mark>งที่</mark> 3 (ครั้งที่ 3)	107
รูปที่4.25	ลักษณะการสังเคราะ <mark>ห์ตัวเร่ง</mark> ปฏิกิริยาซิง <mark>ค์ออ</mark> กไซด์ด้วยกระบวนการแอโนไดเซ	รชัน <u>.</u> 110
รูปที่ 4.26	ภาพถ่าย FESEM ข <mark>อง Z</mark> nO ที่ผ่านการแอโน <mark>ไดซ์ใ</mark> น NH₄F 0.2 โมลาร์ ที่อุณห	ภูมิห้อง
-	โดยเปลี่ยนแปลงค <mark>ว</mark> ามต่างศักย์ และระยะเวลาที่ใ <mark>ช้</mark> ในการแอโนไดซ์	112
รูปที่ 4.27	ภาพถ่าย FESE <mark>M เ</mark> มื่อ <mark>ทำการแอโนไดช์ซิงค์ออกไซด์ในแ</mark> อมโมเนียมฟลูออไรด์	
	0.2 โมลาร์ ค <mark>วา</mark> มต่างศักย์คงที่ 3 โวลต์ ที่เวลาต่าง ๆ หลังการล้างด้วย	
	เครื่องอัลตร <mark>าโซนิค</mark>	113
รูปที่ 4.28	ผงตะกอนซิง <mark>ค์ออกไซด์ในน้ำ DI เมื่อผ่านการอัลตราโซนิค</mark>	
รูปที่ 4.29	ซิงค์ออกไซด์หลังอ <mark>บที่อุณหภูมิต่าง</mark> ๆ	114
รูปที่ 4.30	ภาพถ่าย FESEM ของซิ่งค์ออกหลังอบที่อุณหภูมิต่าง ๆ	115
รูปที่ 4.31	ภาพถ่าย AFM ของซิงค์ออกไซด์ที่ผ่านการแอโนไดซ์ใน NH₄F 0.2 โมลาร์	
-	ที่อุณหภูมิห้อง และความต่างศักย์ 3 โวลต์ ที่ระยะเวลาต่าง ๆ	117
รูปที่ 4.32	XRD ของ ZnO ที่ผ่านการแอโนไดซ์ใน NH4F 0.2 โมลาร์ ที่อุณหภูมิห้อง	
	ความต่างศักย์ 3 โวลต์ ที่ระยะเวลาต่าง ๆ	
รูปที่ 4.33	XRD ของ ZnO ที่ผ่านการแอโนไดซ์ใน NH₄F 0.2 โมลาร์ที่อุณหภูมิห้อง	
	ความต่างศักย์ต่าง ๆ ที่ระยะเวลาเท่ากัน คือ 30 นาที <u>.</u>	119
รูปที่ 4.34	UV-VIS ของซิงค์ที่ผ่านการขัด และซิงค์ออกไซด์ที่ผ่านการแอโนไดซ์ที่เวลาต่าง	งกัน <u>1</u> 20
รูปที่ 4.35	อิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นในรูปของ Photocurrent density ของ ZnO	
	เปรียบเทียบ ZnO ที่ผ่านการฉายแสง และไม่ผ่านการฉายแสง	121
รูปที่ 4.36	อิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นในรูปของ Photocurrent density ของ ZnO	
	ที่ผ่านการแอโนไดซ์จ่ายความต่างศักย์คงที่ 3 โวลต์ เท่ากัน ที่ระยะเวลาต่าง ๆ	122

ิย	
หน	า

รูปที่ 4.37	อิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นในรูปของ Photocurrent density ของ ZnO	
0	ที่ผ่านการแอโนไดซ์ที่ความต่างศักย์ต่าง ๆ ระยะเวลาเท่ากัน คือ 30 นาที	_123
รูปที่ 4.38	อิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นในรูปของ Photocurrent density ของ ZnO	
U	เปรียบเทียบการฉายแส <sup>้</sup> งจากแหล่งกำเนิดต่างกัน	_124
รูปที่ 4.39	การตอบสนองต่อแสงของซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการแอโนไดเซชัเ	J
0	ในสารละลาย Na₂SO₄ 0.1 โมลาร์ จ่ายความต่างศักย์คงที่ 0.5 โวลต์	_125
รูปที่ 4.40	ชุดการทดลองการหาค่าซีโอดีด้วย <mark>กร</mark> ะบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส	<u> 126 </u>
รูปที่ 4.41	การตอบสนองของกระแสไฟฟ้าจ <mark>าก</mark> กระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส	
·	ซีโอดีความเข้มข้นต่าง ๆ	127
รูปที่ 4.42	ถังปฏิกรณ์สำหรับวัดซีโอดี	128
รูปที่ 4.43	การต <sup>ื</sup> อบสนองของกระแสไฟฟ้า <mark>จ</mark> ากกระ <mark>บ</mark> วนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสของซีโอดี	
	ที่ความเข้มข้นของสารละลาย <mark>อิเล</mark> ็กโตรไลต์ <mark>ต่าง</mark> กัน	129
รูปที่ 4.44	การตอบสนองของกระแสไ <mark>ฟฟ้า</mark> จากกระบ <mark>วนก</mark> ารโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสของซีโอดี	
	ที่ความต่างศักย์ต่างกัน	<u> 1</u> 30
รูปที่ 4.45	การตอบสนองของกร <mark>ะแสไ</mark> ฟฟ้าจากกระบวนการ <mark>โพโต</mark> อิเล็กโตรคะตะไลซิส	
	วัดความเข้มข้นซีโอ <mark>ดี</mark> ของกลูโคส 50 มิลลิกรัมต่อลิ <mark>ต</mark> ร วัดที่ระยะเวลาต่างกัน	<u> 131 </u>
รูปที่ 4.46	การหลุดลอกของ <mark>ซิ</mark> งค์อ <mark>อกไซด์ในน้ำตัวอย่างท</mark> ี่ผ่านก <mark>ารวัดซีโอดี</mark>	
-	ด้วยกระบวน <mark>การ</mark> โพโตอิเล็กโตร <mark>คะต</mark> ะไลซิส	<u>132</u>
รูปที่ 4.47	ก) พลาสติก PET ข) เตรียมชิ้นงานใส่ห้องเคลือบสุญญากาศ	_133
รูปที่ 4.48	ฐานรองรับห <mark>ลังทำการสปัตเตอร์ด้วย ก) Ag ข) Ag และ</mark> ITO ตามลำดับ	_133
รูปที่ 4.49	ซิงค์ออกไซด์ที่ผ่าน <mark>การสปัตเตอร์เป็นเว</mark> ลา ก) 30 นาที ข) 120 นาที	_134
รูปที่ 4.50	XRD ของ ZnO ที่ผ่านการสปัตเตอริงบน PET	_135
รูปที่ 4.51	XPS ของ ZnO ที่ผ่านการสปัตเตอริงบน PET	_136
รูปที่ 4.52	โพลิไอมายด์ฟิล์มที่เคลือบด้วยทองแดง	
	และซิงค์ออกไซด์ที่ผ่านการสปัตเตอร์ที่เวลาต่าง ๆ	.137
รูปที่ 4.53	ภาพถ่าย FESEM และ EDS สเปกตรัมของซิงค์ออกไซด์ที่สปัตเตอริง	
	ที่ระยะเวลาต่าง ๆ	139
รูปที่ 4.54	UV-VIS ของซิงค์ออกไซด์ที่ผ่านการสปัตเตอริงที่ระยะเวลาต่างกัน	<u> 1</u> 43
รูปที่ 4.55	แสดงการตอบสนองต่อแสงของตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์	
	(ก่อนปรับปรุงแหล่งกำเนิดแสง)	_144
รูปที่ 4.56	แสดงการตอบสนองต่อแสงของตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์	
	(หลังปรับปรุงแหล่งกำเนิดแสง <b>)</b> ปิด-เปิดไฟสลับกัน	<u>145 .</u>
รูปที่ 4.57	แสดงการตอบสนองต่อแสงของตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์	
	(หลังปรับปรุงแหล่งกำเนิดแสง <b>)</b> ปิด-เปิดแหล่งจ่ายความต่างศักย์สลับกัน	<u>145 .</u>

		หน้า
รูปที่ 4.58	เครื่องโพเทนชิโอสแตทที่ใช้ในกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส	146
รูปที่ 4.59	ทดสอบการวัดซ้ำของสารละลายอิเล็กโตรไลต์ Na <sub>2</sub> SO4 0.1 โมลาร์	147
รูปที่ 4.60	เครื่องมัลติมิเตอร์ที่ประยุกต์ใช้ในกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส	
	เพื่อวัดซีโอดี	147
รูปที่ 4.61	การตอบสนองของกระแสไฟฟ้าของตัวเร่งปฏิกิริยาที่สปัตเตอริง	
	เป็นเวลา 60 นาที วัดซีโอดี (กลูโคส) 10 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร	
	จ่ายความต่างศักย์คงที่ ก) 0.1 โว <mark>ลต์</mark> ข) 0.2 โวลต์ <u>.</u>	148
รูปที่ 4.62	การตอบสนองของกระแสไฟฟ้าข <mark>องต</mark> ัวเร่งปฏิกิริยาที่สปัตเตอริง	
	เป็นเวลา 120 นาที วัดซีโอดี (ก <mark>ลูโคส</mark> ) 10 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร	
	จ่ายความต่างศักย์คงที่ ก) 0.1 <mark>โวลต์ ข</mark> ) 0.2 โวลต์ <u></u>	149
รูปที่ 4.63	การตอบสนองของกระแสไฟฟ้ <mark>า</mark> ของตัว <mark>เ</mark> ร่งปฏิกิริยาที่สปัตเตอริง	
	เป็นเวลา 240 นาที วัดซีโอ <mark>ดี (ก</mark> ลูโคส) <mark>1</mark> 0 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร	
	จ่ายความต่างศักย์คงที่ ก) <mark>0.1</mark> โวลต์ ข) <mark>0.2</mark> โวลต์ <u></u>	149
รูปที่ 4.64	การตอบสนองของกร <mark>ะแส</mark> ไฟฟ้าของตัวเร่งปฏิกิริยาที่สปัตเตอริง	
	เป็นเวลา 120 นาที <mark>วัดซ</mark> ีโอดี (กลูโคส) 100 ม <mark>ิลลิก</mark> รัมต่อลิตร	
	จ่ายความต่างศักย์คงที่ 0.2 โวลต์	150
รูปที่ 4.65	แสดงการเปรีย <mark>บเ</mark> ทียบพื้นที่ใต้กราฟจากการวัดกระแสของ Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 0.1 โมลาร์	
	เมื่อใช้ขั้วไฟฟ้ <mark>าร่ว</mark> มเป็น ก) แกรไฟต์ และ ข) แพลตทิ <mark>นัม</mark>	151
รูปที่ 4.66	การวัดซีโอดี <mark>ด้วยกร</mark> ะบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไ <mark>ลซิส</mark>	
	ก) วัดซีโอดีจ <mark>ากความเข้มข้นต่ำไปสูง ข) วัดซีโอดีจากคว</mark> ามเข้มข้นสูงไปต่ำ	<u>   152                                 </u>
รูปที่ 4.67	ความสัมพันธ์ระห <mark>ว่างค่าซีโอดีทางทฤษฎีและ Q<sub>ret</sub> จากกร</mark> ะบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไ	ନଟ୍ପି ଶ
	จากการวัดซีโอดีที่ความเข้มข้นต่ำไปสูง	<u>1</u> 53
รูปที่ 4.68	ความสัมพันธ์ระหว่างค่าซีโอดีทางทฤษฎีและ Q <sub>net</sub> จากกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไ	ନଟ୍ପି ଶ
	จากการวัดซีโอดีที่ความเข้มข้นสูงไปต่ำ	153
รูปที่ 4.69	การวัดซีโอดีจากกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส ความเข้มข้นของซีโอดี	
·	ก) 5 10 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ข) 100 200 และ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร <u></u>	155
รูปที่ 4.70	ความสัมพันธ์ระหว่างค่าซีโอดีทางทฤษฎีและค่าซีโอดี	
	จากกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสที่ความเข้มข้นต่าง ๆ	156
รูปที่ 4.71	การวัดซีโอดีของ KHP จากกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส	
	ความเข้มข้นของซีโอดี 0-150 มิลิกรัมต่อลิตร <u>.</u>	157
รูปที่ 4.72	ความสัมพันธ์ระหว่างค่าซีโอดีทางทฤษฎีและค่าซีโอดี	
	จากกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสที่ความเข้มข้นต่าง ๆ	158
รูปที่ 4.73	การจ่ายความต่างศักย์ไฟฟ้าของ Q <sub>(blank)</sub> และ Q <sub>(total)</sub>	159

		หน้า
รูปที่ 4.74	พื้นที่ใต้กราฟของสารละลายอิเล็กโทรไลต์โซเดียมซัลเฟต 0.1 โมลาร์	
	โดยเพิ่มปริมาตรน้ำตัวอย่างครั้งละ 0.5 มิลลิลิตร ในการวัดแต่ละรอบ	
	จ่ายความต่างศักย์ 0.2 โวลต์ ไปยังตัวเร่งปฏิริยาซิงค์ออกไซด์	160
รูปที่ 4.75	พื้นที่ใต้กราฟของซีโอดีความเข้มข้นตั้งแต่ 0-200 มิลลิกรัมต่อลิตร	
	โดยเพิ่มปริมาตรน้ำตัวอย่างครั้งละ 0.5 มิลลิลิตร ในการวัดแต่ละรอบ	
	จ่ายความต่างศักย์ 0.2 โวลต์ ไปยังตัวเร่งปฏิริยาซิงค์ออกไซด์	161
รูปที่ 4.76	พื้นที่ใต้กราฟของซีโอดีความเข้มข <mark>้นตั้</mark> งแต่ 0-200 มิลลิกรัมต่อลิตร	
	โดยที่ไม่มีการเคลื่อนย้ายตำแหน่ง <mark>อุป</mark> กรณ์ในการวัด	
	จ่ายความต่างศักย์ 0.5 โวลต์ ไป <mark>ยัง</mark> ตั <mark>วเร</mark> ่งปฏิริยาซิงค์ออกไซด์	162
รูปที่ 4.77	การวัดซีโอดีจากกระบวนการโ <mark>ฟโตอิเล็ก</mark> โตรคะตะไลซิส	
	ความเข้มข้นซีโอดีของ KHP 0 <mark>-</mark> 150 ม <mark>ิล</mark> ิกรัมต่อลิตร	163
รูปที่ 4.78	ภาพถ่าย FESEM ของซิงค์อ <mark>อกไซ</mark> ด์เปรียบ <mark>เทีย</mark> บก่อนและหลังใช้วัดซีโอดี	165
รูปที่ 4.79	แสดง EDS สเปกตรัม ขอ <mark>งซิง</mark> ค์ออกไซด์ <mark>หลัง</mark> นำไปวัดซีโอดี	165
รูปที่ ก.1	กล้องจุลทรรศน์อิเล็ก <mark>ตรอนแบบส่องกราดความล</mark> ะเอียดสูง	184
รูปที่ ก.2	กล้องจุลทรรศน์แรง <mark>อะต</mark> อม	185
รูปที่ ก.3	เครื่องวัดความหน <mark>าฟิล์ม</mark> ด้วย <mark>แสง</mark>	186
รูปที่ ก.4	การหักเหของรั <mark>งสี</mark> X-Ray	187
รูปที่ ก.5	ส่วนประกอบ <mark>หลั</mark> กขอ <mark>งเครื่อง</mark> X-ray Photoelectron Spectroscopy	188
รูปที่ ก.6	การวิเคราะห์ <mark>การต</mark> อบสนองปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีแสง <mark>ด้วยเค</mark> รื่องโพเทนซิโอสแตท <u></u>	189
รูปที่ ก.7	เครื่องตรวจวัดสารด้วยการดูดกลืนแสง	190
รูปที่ ก.8	Inductively Couple Plasma Mass Spectrometer	<u>   1</u> 91
รูปที่ ข.2	ติดพัดลมระบายอากาศเพื่อลดอุณหภูมิเครื่องแหล่งกำเนิดแสง	194
รูปที่ ข.3	พื้นที่ใต้กราฟ (Q) ที่ความต่างศักย์ใด ๆ	197
รูปที่ ข.4	แสดงค่าวิกฤต เสอเกษาเป็นเลื่อ	<u>   198                                 </u>
รูปที่ ข.5	เปรียบเทียบการย่อยเมทิลีนบลูด้วยกระบวนการโฟโตไลซิส	
	และกระบวนการโฟโตคะตะไลซิสที่ใช้ตัวเร่งปฏิริยาแตกต่างกัน	201

### บทที่ 1 บทนำ

### 1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย

โลกของเราประกอบขึ้นด้วยพื้นดินและพื้นน้ำ โดยส่วนที่เป็นผืนน้ำนั้น มีอยู่ประมาณ 3 ส่วน (75%) และเป็นพื้นดิน 1 ส่วน (25%) น้ำเป็นทรัพยากรที่สามารถเกิดหมุนเวียนได้เรื่อย ๆ ไม่มีวันหมด สิ้น ซึ่งเกิดขึ้นเป็นวัฏจักรหมุนเวียนต่อเนื่องกันตลอดเวลา น้ำมีความสำคัญอย่างยิ่งกับชีวิตของพืชและ สัตว์บนโลกรวมทั้งมนุษย์เราด้วย และยังมีความจำเป็นทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ซึ่งมี ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ แบ่งเป็นปัญหาที่สำคัญ ๆ ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ปัญหาน้ำท่วม และปัญหาน้ำเสีย ซึ่งปัญหาน้ำเสียเป็นปัญหาที่มีความสำคัญ อย่างยิ่งในปัจจุบัน โดยแหล่งที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดน้ำเสีย มีดังนี้ น้ำทิ้งจากบ้านเรือน น้ำเสียจาก โรงงานอุตสาหกรรม น้ำฝนพัดพาเอาสารพิษที่ตกค้างจากแหล่งเกษตรกรรมลงสู่แม่น้ำลำคลอง รวมถึง ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกทิ้งลงสู่แม่น้ำลำคลองกีทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย น้ำเสียที่เกิดขึ้นนี้เป็น อันตรายต่อสัตว์น้ำ ส่งผลเสียหายต่อสุขภาพอนามัย ของมนุษย์ ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน และทำให้ไม่ สามารถนำแหล่งน้ำนั้นมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งการอุปโภค บริโภค เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ในการ ตรวจสอบความสกปรกของน้ำเสียจำเป็นต้องมีดัชนีหรือตัวชี้วัด ซึ่งในการวิเคราะห์คุณลักษณะของน้ำ เสียที่นิยม ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าออกซิเจนละลาย (DO), ค่าบิโอดี (BOD), ค่าซีโอดี (COD), ค่าความ กรด-ด่าง (pH) เป็นต้น

้ค่าซีโอดี (Chemical oxyg<mark>e</mark>n demand: COD) เป็นวิธีวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนทั้งหมดที่ ้ต้องการ เพื่อใช้ในการออกซิไดซ์ (Oxidize) สารอินทรีย์ในน้ำให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ ้ ค่าซีโอดีเป็นพารามิเตอร์ที่สำคั<mark>ญที่</mark>ใช้ใ<mark>นการปร</mark>ะเมินคุณภาพน้ำเสีย รวมไปถึงใช้ในการออกแบบ ติดตาม ควบคุม และประเมินประสิท<mark>ธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยเหตุที่</mark>การวิเคราะห์หาค่าซีโอดีนั้น สามารถที่จะทำการวิเคราะห์แ<mark>ละได้รับผลการวิเคราะห์ในช่วงเวลาที่สั้น</mark> (3-5 ชั่วโมง) ซึ่งถ้าเทียบกับ การหาค่าปีโอดี (Biological oxygen demand: BOD) ที่ใช้เวลานานกว่า (5วัน) และมีวิธีการที่ยุ่งยาก ้กว่า ทำให้การวิเคราะห์หาค่าซีโอดี ในน้ำเสียเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งการวิเคราะห์หาค่าซีโอดี ตามวิธีมาตรฐานมีด้วยกัน 3 วิธี ได้แก่ วิธี Open Reflux, วิธี Closed Reflux; Titrimetric Method และ วิธี Closed Reflux; Colorimetric Method ซึ่งในแต่ละวิธีจะมีข้อบ่งชี้ในการใช้ที่แตกต่างกัน แต่ทุกวิธีจะมีหลักการเหมือนกัน กล่าวคือ ค่าซีโอดีจะเป็นปริมาณออกซิเจนทั้งหมดที่ใช้ในการ ้ออกซิไดซ์สารอินทรีย์ในน้ำเสีย โดยที่สารอินทรีย์เกือบทั้งหมด (95 - 100%) จะถูกออกซิไดซ์โดยสาร ออกซิไดซ์อย่างแรง (Strong oxidizing agent) เช่น โปแตสเซียมไดโครเมต (Potassium dichromate, K2Cr2O7) ภายใต้สภาวะที่เป็นกรด หลักการคือ สารอินทรีย์คาร์บอนจะถูกออกซิไดซ์โดยโปแตสเซียมไดโครเมต ในสภาวะที่เป็นกรดอย่างรุนแรง ดังนั้นจึงใช้การ reflux เพื่อป้องกันการระเหยสูญหายของสารเคมี ้จากนั้นจึงไทเทรตหาปริมาณโปแตสเซียมไดโดรเมตที่เหลืออยู่ด้วย ferrous ammonium sulfate โดย ้ใช้ ferroin เป็นอินดิเคเตอร์ มีการเติม AgSO₄ เพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เพื่อเร่งปฏิกิริยาการออกซิไดซ์ ของพวกกรดไขมันที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ ๆ และในการวิเคราะห์ค่าซีโอดีมีสารรบกวนที่สำคัญคือ Cl<sup>-</sup> จึง ้ต้องใส่ HgSO₄ เพื่อไปจับกับ Cl⁻ ให้อยู่ในรูปของ mercuric chloride complex ทำให้ได้ค่าซีโอดีที่ ้ถูกต้อง จากวิธีการวิเคราะห์หาค่าซีโอดีดังที่กล่าวมานั้น ทำให้เห็นว่าในการวิเคราะห์จำเป็นต้องใช้ สารเคมี หลายชนิด ได้แก่ K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> และ HgSO<sub>4</sub> โดยสาร K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> และ HgSO<sub>4</sub> เป็น สารเคมีอันตราย H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> เป็นกรดชนิดเข้มข้นมีความสามารถในการกัดกร่อนสูง และ Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ที่ใช้การ วิเคราะห์ซีโอดีนี้เป็นสารเคมีที่มีราคาแพง ซึ่งทั้งหมดนี้ถือได้ว่าเป็นข้อเสียของการวิเคราะห์หาค่าซีโอดี ตามวิธีมาตรฐาน (ใช้ K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> เป็นตัว oxidizing agent)

ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมามีนักวิจัยคิดค้นวิธีการหาค่าซีโอดีด้วยวิธีต่างๆ เช่น อาศัย หลักการออกซิไดซ์โดยคลื่นไมโครเวฟ (microwave-assisted) หรือหลักการอัลตราซาวน์ (ultrasound-assisted (Domini et al., 2006) เพื่อช่วยในการออกซิไดซ์สารอินทรีย์ และยังมีการเพิ่ม ้ตัว oxidizing agent เพื่อให้การออกซิไดซ์สารอินทรีย์ได้ดีขึ้น (Domini et al., 2009) หรืออาศัย หลักการทาง electrochemical sensor ในการหาค่าซีโอดีโดยใช้ nano-PbO<sub>2</sub> (Ai et al., 2004) ใช้ nano-Cu (Yang et al., 2010) หรือใช้วัสดุผสม Ti/Sb-SnO<sub>2</sub>/PbO<sub>2</sub> เป็นอิเล็กโทรด (Ma et al., 2010) ้นักวิจัยหลายกลุ่มยังได้ศึกษาการประยุกต์ใช้กระ<mark>บว</mark>นการโฟโตคะตะไลติกเพื่อช่วยในการย่อยสลาย ้สารอินทรีย์แทนการใช้สารเคมี โดยมีการใช้ตัวเร่ง<mark>ปฏ</mark>ิกิริยาหลายๆ รูปแบบ เช่น TiO<sub>2</sub> ในรูปแบบเม็ด ลูกปัด (Kim et al., 2001) ฟิล์มบาง TiO<sub>2</sub> (Chen et al., 2005) วัสดุผสมระหว่าง ZnO/TiO<sub>2</sub> (Zhang et al., 2007) อนุภาคนาโน TiO<sub>2</sub> เคลือบบนแ<mark>ผ่</mark>น Ti <mark>แ</mark>ละมีการเติมตัว oxidizing agent (Zhang et al., 2011) หรือใช้ CdTe quantum dots (Silvestre et al., 2011) นอกจากกระบวนการโฟโตคะ ตะไลซิสที่สามารถประยุกต์ใช้ในการวิ<mark>เค</mark>ราะห์หาค่าซีโอดีแล้ว วิธีการ ้โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสก็ยังมีการศึกษาเ<mark>พื่อใช้วิ</mark>เคราะห์<mark>หาค</mark>่าซีโอดีเช่นกัน ซึ่งแต่ละกลุ่มวิจัยได้ศึกษา ้ ตัวเร่งปฏิกิริยาต่าง ๆ กัน ได้แก่ Zha<mark>o et</mark> al., 2004 ประยุ<mark>กต์ใช้</mark>ฟิล์ม TiO<sub>2</sub> แบบ nanoporous เป็น ตัวเร่งปฏิกิริยา Zhang et al., 2009 ใช้ TiO2 nanotubes เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา Mu et al., 2011 ใช้ TiO<sub>2</sub> ชนิด nanofiber เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เป็นต้น

ซึ่งจากการที่ผู้วิจัยเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานในการสังเคราะห์วัสดุกึ่งตัวนำชนิดต่าง ๆ (TiO<sub>2</sub>, WO<sub>3</sub>, ZnO เป็นต้น) ที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในกระบวนการโพโตคะตะไลซิส และทำโครงการวิจัย เกี่ยวกับกระบวนการโพโตคะตะไลซิสมาก่อนแล้ว รวมทั้งได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวการวิเคราะห์ซีโอดี ด้วยวิธีการต่าง ๆ เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะศึกษาและพัฒนาวิธีการเหล่านั้นเพื่อใช้วิเคราะห์ค่าซีโอดี ของน้ำเสียเพื่อลดปัญหาของการวิเคราะห์หาค่าซีโอดีตามวิธีมาตรฐาน ซึ่งต้องใช้สารเคมีที่อันตราย มี ความเป็นพิษ มีราคาแพง และใช้เวลาในการวิเคราะห์นาน ซึ่งผู้วิจัยมุ่งเน้นที่จะศึกษาวิธีการ โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส โดยใช้วัสดุกึ่งตัวนำต่าง ๆที่สังเคราะห์ขึ้น ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีความ น่าสนใจ ที่สามารถจะลดปัญหาและข้อจำกัดดังกล่าวได้ เนื่องจากคุณสมบัติของวัสดุกึ่งตัวนำที่ สังเคราะห์มาใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นตัวกลางที่มีเสถียรภาพ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยัง สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้ง และกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสก็เป็นอุ่งปฏิกิริยาเป็นตัวกลางที่มีเสถียรภาพ ไม่เป็นจิธีการวิเคราะห์ที่ไม่ยุ่งยาก และใช้เวลาในการวิเกราะห์อื่น เนื่องากมู่พื้นจากมูนที่สังเคราะห์ขึ้น ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีความ น่าสนใจ ที่สามารถจะลดปัญหาและข้อจำกัดดังกล่าวได้ เนื่องจากคุณสมบัติของวัสดุกึ่งตัวนำที่ สังเคราะห์มาใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นตัวกลางที่มีเสถียรภาพ ไม่เป็นจิธีการวิเคราะห์ที่ไม่ยุ่งยาก และใช้เวลาน้อยอีกด้วย

#### 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

1.2.1 เพื่อศึกษาการใช้กระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสในการวิเคราะห์หาค่าซีโอดีใน น้ำเสีย

1.2.2 เพื่อศึกษาถึงความถูกต้องและแม่นยำของการใช้วัสดุกึ่งตัวนำชนิดต่าง ๆ ในการ วิเคราะห์ค่าซีโอดีในน้ำเสียโดยใช้กระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส

### 1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย

งานวิจัยนี้เน้นศึกษาการหาค่าซีโอดี ด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส โดยใช้วัสดุกึ่ง ตัวนำ TiO<sub>2</sub> และวัสดุกึ่งตัวนำ ZnO ซึ่งในการตรวจสอบความถูกต้องและความแม่นยำของกระบวนการ นี้ จะศึกษาเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์หาค่าซีโอดีด้วยวิธีมาตรฐานไดโครเมต (K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>) และใช้ ทดลองกับสารอินทรีย์ที่ให้ค่าซีโอดีในเชิงทฤษฎี ท<mark>ำกา</mark>รศึกษาเกี่ยวกับตัวรบกวนการวิเคราะห์ค่าซีโอดี

### 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ได้วิธีการวิเคราะห์หาค่าซีโอดีที่สามารถลดปัญหาของวิธีการวิเคราะห์หาค่าซีโอดี ตาม วิธีมาตรฐาน อีกทั้งได้วิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

1.4.2 เป็นองค์ความรู้ในการวิจัยต่อไป เนื่องจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับการหาค่าซีโอดี โดยวิธีโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสในประเทศไทยยังไม่ได้รับความนิยม ดังนั้น จึงสามารถนำงานวิจัยนี้ไป ศึกษาต่อเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป

1.4.3 ทำให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา และทราบถึงความถูกต้อง แม่นยำของตัวเร่งปฏิกิริยาในการวิเคราะห์หาค่าซีโอดี เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐานไดโครเมต



### บทที่ 2 ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

#### 2.1 ซีโอดี

#### 2.1.1 ความสำคัญของการวิเคราะห์ซีโอดี

ค่าซีโอดี (Chemical oxygen demand, COD) เป็นวิธีวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจน ทั้งหมดที่ต้องการเพื่อใช้ในการออกซิไดซ์ (Oxidize) สารอินทรีย์ในน้ำให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ ค่าซีโอดีเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญที่ใช้ในการประเมินคุณภาพน้ำเสีย รวมไปถึงใช้ในการออกแบบ ติดตามควบคุม และประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย นอกจากนี้ยังทำให้ทราบถึงผลกระทบ และศักยภาพของแหล่งรองรับน้ำทิ้งว่าจะสามารถรับความสกปรกได้มากน้อยเพียงใดด้วย และด้วยเหตุ ที่การวิเคราะห์หาค่าซีโอดีนั้น สามารถที่จะทำการวิเคราะห์และได้รับผลการวิเคราะห์ในช่วงเวลาที่สั้น (3-5 ชั่วโมง) ซึ่งถ้าเทียบกับการหาค่าบีโอดี (BOD) ที่ใช้เวลานานกว่า (5วัน) และมีวิธีการที่ยุ่งยากกว่า จึงทำให้มีประโยชน์อย่างมากในการควบคุมและแก้ไขปัญหาในเรื่องของมลพิษทางน้ำได้เป็นอย่างดีและ ทันท่วงที ทำให้การวิเคราะห์หาค่าซีโอดี ในน้ำเสียเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย

### 2.1.2 ทฤษฎีของซีโอดีและหลักการวิเคราะห์พื้นฐาน

การวิเคราะห์หาค่าซีโอดีตามวิธีมาตรฐานมีด้วยกัน 3 วิธี ได้แก่ วิธีรีฟลักซ์แบบเปิด (Open Reflux) วิธีรีฟลักซ์แบบปิด/ไทเทรต (Closed Reflux/Titrimetric Method) และวิธีรีฟลักซ์ แบบปิด/เปรียบเทียบสี (Closed Reflux/Colorimetric Method) โดยที่วิธีวิธีรีฟลักซ์แบบเปิดจะ เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ค่าซีโอดีในตัวอย่างน้ำเสียหลากหลายชนิดโดยใช้ปริมาณตัวอย่างน้ำในการ วิเคราะห์จำนวนมาก เพื่อลดความผิดพลาดในการสุ่มตัวอย่างและการปิเปตตัวอย่าง แต่จะใช้ สารประกอบโลหะต่าง ๆ ในปฏิกิริยาจำนวนมากตามไปด้วย ส่วนวิธี Closed Reflux ทั้งสองแบบ เป็น วิธีการวิเคราะห์ที่ค่อนข้างประหยัดการใช้สารประกอบโลหะต่าง ๆ ในปฏิกิริยา แต่จะมีความผิดพลาด ในการปิเปตตัวอย่างหากตัวอย่างไม่ผสมกันดีเพียงพอเนื่องจากใช้ปริมาณตัวอย่างในการวิเคราะห์น้อย มาก จะเห็นได้ว่าในแต่ละวิธีจะมีข้อบ่งชี้ในการใช้ที่แตกต่างกัน แต่ทุกวิธีจะมีหลักการเหมือนกัน กล่าวคือ ค่าซีโอดีจะเป็นปริมาณออกซิเจนทั้งหมดที่ใช้ในการออกซิไดซ์สารอินทรีย์ในน้ำเสีย โดยที่ สารอินทรีย์เกือบทั้งหมด (95-100%) จะถูกออกซิไดซ์โดยสารออกซิไดซ์อย่างแรง (Strong oxidizing agent) ภายใต้สภาวะที่เป็นกรด ดังสมการ 2.1

$$C_nH_aO_bN_c + (n + a/4 - b/2 - 3/4c) O_2 \rightarrow CO_2 + (a/2 - 3/2c) H_2O + cNH_3$$
 (2.1)

โดยสารออกซิไดซ์อย่างแรง (Strong oxidizing agent) ที่ใช้ในการหาค่าซีโอดีมี ด้วยกันหลายตัว ได้แก่ โปแตสเซียมเปอร์แมงกาเนต (Potassium permanganate) เฟอร์ริกซัลเฟต (Ferric sulfate) โปแตสเซียมไอโอเดต (Potassium iodate) และโพแตสเซียมไดโครเมต (Potassium dichromate) ซึ่งการหาค่าซีโอดีโดยใช้โปแตสเซียมไดโครเมตเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมาก เพราะให้ผลที่ น่าเชื่อถือและแน่นอน หลักการของวิธีนี้คือ สารอินทรีย์คาร์บอนจะถูกออกซิไดซ์โดยโปแตสเซียมไดโคร เมตในสภาวะที่เป็นกรดอย่างรุนแรง ดังนั้นจึงใช้การรีฟลักซ์เพื่อป้องกันการระเหยสูญหายของสารเคมี จากนั้นจึงไทเทรตหาปริมาณโปแตสเซียมไดโดรเมตที่เหลืออยู่ด้วยเฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟต (FAS) โดยใช้เฟอโรอินเป็นอินดิเคเตอร์ (มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์, 2543) ปฏิกิริยาที่เกิดเป็นดังนี้

$$3 \text{Org.carbon} + 2 \text{Cr}_2 \text{O}_7^{2-} + 16 \text{H}^+ \rightarrow 3 \text{CO}_2 + 4 \text{Cr}^{3+} + 8 \text{H}_2 \text{O}$$
 (2.2)

$$Cr_2O_7^{2-} + 6Fe^{2+} + 14H^+ \rightarrow 6Fe^{3+} + 2Cr^{3+} + 7H_2O$$
 (2.3)

มีการเติมซิลเวอร์ซัลเฟต (Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) เพื่อเร่งปฏิกิริยาการออกซิไดส์ของพวกกรดไขมัน ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ ๆ (Straight chain aliphatic) นอกจากนี้ ซิลเวอร์ซัลเฟตที่ใส่ไปจะไปทำ ปฏิกิริยากับสารประกอบเฮไลด์ (Halide Compounds) พวกคลอไรด์ (Cl<sup>-</sup>) โบรมีน (Br<sup>-</sup>) หรือไอโอดีน (I<sup>-</sup>) ได้ แต่ซิลเวอร์ซัลเฟตเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ไม่ได้ผลในการออกซิไดส์สารประกอบพวกอะโรมาติก (aromatic) อะลิฟาติก (Aliphatic) และสารไพริดีน (Pyridine) และในการวิเคราะห์ค่าซีโอดีมีสาร รบกวนที่สำคัญคือคลอไรด์จึงต้องใส่เมอร์คิวริกซัลเฟต (HgSO<sub>4</sub>) ลงไปเพื่อไปจับกับคลอไรด์ให้อยู่ในรูป ของสารประกอบเมอร์คิวริกคลอไรด์ (Mercuric chloride complex) ทำให้ได้ค่าซีโอดีที่ถูกต้อง โดยวิธี นี้สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างที่มีค่าซีโอดี ตั้งแต่ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ขึ้นไปได้และมีความแน่นอน

2.1.3 สารรบกวนที่มีผลต่อก<mark>ารวิ</mark>เคราะห์ซีโอ<mark>ดี</mark>ด้วยการวิเคราะห์หาค่าซีโอดีตามวิธี มาตรฐาน

โดยทั่วไปสารประกอบอินทรีย์ส่วนใหญ่ถูกออกซิไดซ์อยู่ในช่วง 95 ถึง100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับค่าที่ได้จากการคำนวณในทางทฤษฎี สารไพริดีนและสารประกอบของไพริดีนจะต่อต้าน การออกซิไดซ์สารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ง่าย (Volatile Organic Compounds) โดยเฉพาะ สารประกอบพวกอะลิฟาติกประเภทโซ่ตรงที่ระเหยได้ง่ายจะถูกออกซิไดซ์ไม่หมดโดยจะถูกออกซิไดซ์ จนถึงระดับหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ง่ายจะลอยตัวอยู่ในบริเวณช่องว่าง เหนือชั้นของสารละลายที่เกิดปฏิกิริยาทำให้ไม่ถูกออกซิไดซ์ได้ทั้งหมด ส่วนสารประกอบพวกอะลิฟา ติกประเภทโซ่ตรงจะถูกออกซิไดซ์ได้ดีกว่าสารประกอบพวกอะลิฟาติกประเภทโซ่ตรงที่ระเหยได้ง่ายโดย การเติมซิลเวอร์ชัลเฟตลงไปในปฏิกิริยาเพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา นอกจากนี้ซิลเวอร์ชัลเฟตที่ใส่ไปจะไป ทำปฏิกิริยากับสารประกอบเฮไลด์ได้ อย่างไรก็ตามถ้าในน้ำตัวอย่างมีปริมาณเฮไลด์ไอออนมากจะทำให้ เกิดเป็นตะกอนของซิลเวอร์เฮไลด์ทำให้ปริมาณซิลเวอร์ชัลเฟตลดลงและไม่เพียงพอต่อการเกิดปฏิกิริยา อย่างสมบูรณ์ และยังทำให้ผลการวิเคราะห์ค่าซิโอดีที่ได้มีค่ามากกว่าความเป็นจริงด้วย ดังนั้นจึงต้องใส่ เมอร์คิวริกซัลเฟต ลงไปก่อนเพื่อไปจับกับคลอไรด์ (Zhang, Zhoua and Zhou, 2011) ให้อยู่ในรูปของ สารประกอบเมอร์คิวริกคลอไรด์ทำให้ได้ค่าซีโอดีที่ถูกต้อง (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 2005 และไพทูรย์ หมายมั่นสมสุข, 2555) ซึ่งการทำปฏิกิริยาระหว่าง คลอไรด์ไอออนและซิลเวอร์ซัลเฟตเกิดขึ้นดังสมการ (2.4) ถึง (2.8) การทำปฏิกิริยาระหว่างคลอไรด์ไอออนและซิลเวอร์ซัลเฟต

$$Ag_2SO_4 + 2Cl^- \rightarrow AgCl + SO_4^{2-}$$
(2.4)

การทำปฏิกิริยาระหว่างคลอไรด์ไอออนและไดโครเมต

$$2Cl^{-} \rightarrow Cl_{2} + 2e^{-} \tag{2.5}$$

$$Cr_2O_7^{2-} + 6Cl^- + 14H^+ \rightarrow 2Cr^{3+} + 3Cl_2 + 7H_2O$$
 (2.7)

เติมเมอร์คิวริกซัลเฟต (<mark>Me</mark>rcuric Sulfate, HgSO₄) เพื่อป้องกันการรบกวนการ วิเคราะห์ซีโอดี ซึ่งจะเกิดปฏิกิริยาดังสมการ

$$HgSO_4 + 2Cl^- \longrightarrow HgCl_2 + SO_4^{2-}$$
(2.8)

โดยทั่วไปจะใช้เมอร์คิวริกซัลเฟตในปริมาณ 1 กรัม สำหรับตัวอย่าง 50 มิลลิลิตร กรณี ที่ใช้ตัวอย่างน้อยกว่า 50 มิลลิ<mark>ลิตร</mark> ก็สามารถใช้เมอร์คิวริกซัลเฟตในปริมาณที่ลดลงตามส่วนได้ถ้าทราบ ว่าในตัวอย่างน้ำที่ต้องการวิเคราะห์ค่าซีโอดีมีปริมาณคลอไรด์น้อยกว่า 2,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ทั้งนี้ จะต้องใช้อัตราส่วนของเมอร์คิวริกซัลเฟตและคลอไรด์ไม่น้อยกว่า 10:1

ในไตรท์ไอออน (Nitrite ion, NO<sub>2</sub>) ในทางทฤษฎีจะมีค่าซีโอดี 1.14 มิลลิกรัมต่อ มิลลิกรัมไนไตรท์ในโตรเจน ดังสมการ

$$NO_2^- + H_2O \longrightarrow NO_3^- + 2H^+ + 2e^-$$
(2.9)

$$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \longrightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$$
 (2.10)

$$Cr_2O_7^{2^-} + 3NO_2^{-} + 8H^+ \longrightarrow 2Cr3^+ + 3NO_3^{-} + 4H_2O$$
 (2.11)

จะเห็นว่า ไนไตรท์หรือไนไตรท์ในโตรเจน (Nitrite Nitrogen) 3 โมล ทำปฏิกิริยากับ ไดโครเมต 1 โมล หรือออกซิเจนเทียบเท่า 1.5 โมล นั่นคือ ไนไตรท์ มีค่าซีโอดี 1.14 มิลลิกรัมต่อ มิลลิกรัมไนไตรท์ไนโตรเจน แต่เนื่องจากในตัวอย่างน้ำส่วนใหญ่มีปริมาณไนไตรท์จำนวนน้อยมากซึ่ง ส่วนใหญ่จะน้อยกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตรของไนไตรท์ไนโตรเจน โดยถือว่ามีปริมาณน้อยไม่รบกวนต่อ การวิเคราะห์จึงไม่ต้องนำมาพิจารณา แต่ถ้าในน้ำตัวอย่างมีปริมาณไนไตรท์เกินกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ของไนไตรท์ไนโตรเจน ก็สามารถลดการรบกวนการวิเคราะห์ได้โดยการเติมกรดซัลฟามิก (Sulfamic Acid) ลงไปในปฏิกิริยาในอัตราส่วน 10 มิลลิกรัมของกรดซัลฟามิกต่อ 1มิลลิกรัมในรูปของไนไตรท์ ไนโตรเจน โดยปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นดังสมการ

(2.12)

 $NH_2-SO_3H + HNO_2 + H^+ \rightarrow N \equiv N-SO_3H + 2H_2O$ (Diazonium Salt)

2.1.4 สารมาตรฐานซีโอดี

สารประกอบที่ใช้เป็นมาตรฐานสำหรับการตรวจสอบวิธีการวิเคราะห์และการ ดำเนินการวิเคราะห์ซีโอดีนั้นมีหลายชนิด ได้แก่ น้ำตาลกลูโคส (D-glucose) กรดออกซาลิก (Oxalic acid)โพแทสเซียมไฮโดรเจนพธาเลต (Potassium hydrogen phthalate) กรดกลูตาริก (Glutaric acid) กรดนิโคตินิก (Nicotinic acid) และเมทานอลไพริดีน (Methanol pyridine) แต่ที่ใช้กัน โดยทั่วไปมี 2 ชนิด คือ

2.1.4.1 น้ำตาลกลูโคส (D-glucose)

น้ำตาลกลูโคส (Glucose) เป็น คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) ประเภท น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว (Monosaccharide) มีคาร์บอน 6 อะตอม (Hexose) เซลล์ของสิ่งมีชีวิติทุกชนิดใช้ กลูโคสเป็นแหล่งพลังงานและสารเผาผลาญขั้นกลาง (Metabolic intermediate) กลูโคสเป็นหนึ่งใน ผลิตภัณฑ์หลักของการสังเคราะห์แสง (Photosynthesis) และเป็นแหล่งพลังงานสำหรับการหายใจของ เซลล์ (Cellular respiration) โครงสร้างโมเลกุลตามธรรมชาติของมัน (D-glucose) จะอยู่ในรูปที่ เรียกว่า เดกซ์โตรส (Dextrose) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมอาหาร

ไพฑูรย์ หมายมั่นสมสุข, 2555 กล่าวว่า เมื่อนำกลูโคสมาทำปฏิกิริยากับ โพแทสเซียมไดโครเมตตามวิธีการหาค่าซีโอดี ตามมาตรฐาน กลูโคสจะถูกออกซิไดซ์อย่างสมบูรณ์และ ได้ผลิตภัณฑ์คือ น้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ดังสมการ

ปฏิกิริยาการรีฟลักซ์ในสารละลายกรด

$$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$$
 (2.13)

$$C_6H_{12}O_6 + 4Cr_2O_7^{2-} + 32H^+ \rightarrow 8Cr^{3+} + 22H_2O + 6CO_2$$
 (2.14)

ปฏิกิริยาในกรดซัลฟิวริก

$$C_{6}H_{12}O_{6} + 4K_{2}Cr_{2}O_{7} + 16H_{2}SO_{4} \longrightarrow 4Cr_{2}(SO_{4})_{3} + 4K_{2}SO_{4} + 22H_{2}O + 6CO_{2}$$
(2.15)

กรณีการใช้ออกซิเจนในการออกซิไดซ์กลูโคสในลักษณะเช่นเดียวกับการย่อย สลายกลูโคสแบบสมบูรณ์จะได้ดังสมการ

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$$
 (2.16)

ทั้งนี้เนื่องจาก K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O7 จ<mark>ำน</mark>วน 1 โมล จะมีอำนาจในการออกซิไดซ์เทียบเท่า ้กับ O<sub>2</sub> จำนวน 1.5 โมล จากสมการ (2.15) กลูโค<mark>ส</mark> จำนวน 1 โมล จะทำปฏิกิริยากับโปแทสเซียมได โครเมต จำนวน 4 โมล และจากสมการ (2.16<mark>) กลูโค</mark>ส จำนวน 1 โมล จะทำปฏิกิริยากับออกซิเจน ้จำนวน 6 โมล และกลุโคสมีมวลโมเลกุลเท่ากับ 180 ก<mark>ร</mark>ัมต่อโมล และออกซิเจนมีมวลโมเลกุล เท่ากับ 32 กรัมต่อ โมล ดังนั้นกลูโคส มีค่าซีโอดีเท่ากับ 1.067 กรัมออกซิเจนต่อกรัมกลูโคส

2.1.4.2 โพแทสเซียมไฮโดรเจนพธาเลต (Potassium hydrogen phthalate, KHP) เมื่อนำโพแท<mark>สเซี</mark>ยมไฮโดรเจนพธาเ<mark>ลตม</mark>าทำปฏิกิริยาร่วมกันกับโพแทสเซียม ้ไดโครเมตตามวิธีการหาค่าซีโอดี โพ<mark>แทส</mark>เซียมไฮโดรเจนพธาเล<mark>ตจะ</mark>ถูกออกซิไดซ์อย่างสมบูรณ์และได้ ้ผลิตภัณฑ์คือ โพแทสเซียมออกไซด์ น้ำและก๊าซคาร์ปอนไดออกไซด์ ซึ่งเมื่อเทียบกับการใช้ออกซิเจนใน การออกซิไดซ์จะได้ดังสมการ

 $2KC_8H_5O_4 + 15O_2 \rightarrow K_2O + 16CO_2 + 5H_2O$ (2.17)

10

จากสมการ (2.17) โพแทสเซียมไฮโดรเจนพธาเลตจำนวน 2 โมล จะทำ ปฏิกิริยากับออกซิเจนจำนวน 15 โมล แต่โพแทสเซียมไฮโดรเจนพธาเลตมีมวลโมเลกุลเท่ากับ 204.1 กรัมต่อโมล และออกซิเจนมีมวลโมเลกุลเท่ากับ 32 กรัมต่อโมล ดังนั้นโพแทสเซียมไฮโดรเจนพธาเลตมี ค่าซีโอดี เท่ากับ 1.176 กรัมออกซิเจนต่อกรัมโพแทสเซียมไฮโดรเจนพธาเลต

#### 2.1.5 คุณลักษณะน้ำเสียจากแหล่งต่าง ๆ

้น้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 หมายถึง ของเสียที่อยู่ในสภาพของเหลวรวมทั้งมลสารที่ปะปนและปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น กิจกรรม ้ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์ เป็นตัวการสำคัญในการเพิ่มปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำและก่อให้เกิดน้ำเสียที่ ้มีปริมาณสารอินทรีย์หรือค่าซีโอดีสูง โดยกิจกรรมหลักที่ทำให้เกิดน้ำเสียได้แก่ ชุมชนและพาณิชย์ ์ โรงงานอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม (ตำราระบบบำบัดมลพิษน้ำ, 2552) ดังนี้

#### 2.1.5.1 น้ำเสียชุมชน

น้ำเสียชุมชน หมายถึงน้ำที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากกิจกรรมต่าง ๆ และ ระบายลงสู่ท่อระบายน้ำ แหล่งรองรับน้ำ หรือแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยไม่ได้ผ่านการบำบัดให้มีลักษณะดี ขึ้นหรือสะอาดก่อน ซึ่งทำให้น้ำได้รับความเสื่อมโทรม สามารถสรุปลักษณะน้ำเสียตามกิจกรรมที่เกิดขึ้น ดังตาราง 2.1 และกิจกรรมที่จัดอยู่ในกลุ่มน้ำเสียชุมชนนี้ เช่น

 น้ำเสี่ยจากบ้านเรือนเกิดจากกิจกรรมการใช้น้ำต่าง ๆ ของผู้ที่พักอาศัย ภายในบ้านเรือน เช่น การดื่ม การอาบ การซักล้าง การครัว การทำความสะอาด การกำจัดสิ่งปฏิกูล อัตราการใช้น้ำมักจะไม่ค่อยแน่นอน ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกหลาย ๆ อย่าง เช่น ชนิด และความหนาแน่นของชุมชน ฐานะเศรษฐกิจและนิสัยความเป็นอยู่ สภาวะด้านสุขาภิบาล การ บริการของการประปา โดยลักษณะน้ำเสียที่เกิดจากบ้านเรือนมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับกิจกรรมการ ใช้น้ำและช่วงเวลาของการเกิดน้ำเสีย เช่น น้ำเสียจากครัว (การประกอบอาหาร การล้างภาชนะ) จะมี เศษอาหาร ไขมันและน้ำมันเจือปนเป็นหลัก และน้ำเสียที่เกิดจากการซักล้างหรือการอาบน้ำ จะมีสบู่ สารซักฟอก สำหรับน้ำเสียจากส้วมจะมีสิ่งปฏิกูลและแอมโมเนียเจือปนอยู่ในน้ำเสียด้วย โดยปริมาณน้ำ เสียที่ปล่อยทิ้งจากบ้านเรือนจะมีค่าประมาณร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ หรืออาจประเมินได้จาก จำนวนผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือน คิดเป็นปริมาณน้ำเสียรวม 150 ลิตรต่อคนต่อวัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2555)

2) ภัตตาคารอา<mark>หาร</mark> และโรงแ<mark>รม</mark>มีน้ำเสียที่เกิดจากห้องครัว และห้องส้วม โดยเฉพาะค่าน้ำมันจะทำให้เกิดการอุด<mark>ตันข</mark>องท่อระบายน้ำ

3) โรงแรม<mark>มีน้ำ</mark>เสียจากห้องน้ำและห้องส้วมภายในห้องพัก และห้องครัว ภัตคารภายในโรงแรมอาคารสำนักงาน

> ะ ว่าวักยาลัยเทคโนโลยีสุรบาว

4) กิ<mark>จกร</mark>รมอื่<mark>น ๆ เช่น สถานบริการอา</mark>คาร<mark>พาณิ</mark>ชย์ โรงเรียน อาคารชุด ตลาด

สถานีบริการน้ำมัน เป็นต้น

		ลักษณะน้ำเสีย (มิลลิกรัมต่อลิตร)			
กิจกรรม	ปรีมาณน้ำเสีย	ของแข็ง แขวนลอย	น้ำมัน และไขมัน	ทีเคเอ็น (ไนโตรเจน)	บีโอดี
อาคารชุดและบ้านพัก	520 ลิตรต่อวันต่อห้อง, หลัง	63*	473	33*	151*
โรงแรม	1,061 ลิตรต่อวันต่อห้อง	84	563	23	190
หอพัก	78 ลิตรต่อวันต่อห้อง	660**	377**	329	723**
โรงพยาบาล	800 ลิตรต่อวันต่อเตียง	87	631	15	238
ภัตตาคาร	25 ลิตรต่อวันต่อตารางเมตร	913	1,570	63	1,759
ตลาด	69 ลิตรต่อวันต่อตารางเมตร	660	897	76	1,172
ห้างสรรพสินค้า	4.6 ลิตรต่อวันต่อตารางเ <mark>มตร</mark>	61	577	66	81
สำนักงาน	2.54 ลิตรต่อวันต่อ <mark>ตารา</mark> งเมตร	158	450	44	180

ตารางที่ 2.1 ลักษณะน้ำเสียตามกิจกรรมต่าง ๆ

<u>หมายเหตุ</u> จากตำราระบบบำบัดมลพ<mark>ิษน้</mark>ำ พิมพ์ครั้งที่ 1, โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2545

\* หมายถึงบำบัดแล้วบา<mark>ง</mark>ส่วน

\*\* หมายถึงน้ำเสียจากส้วม

#### 2.1.5.2 น้ำเสียจากโรงพยาบาล

ตามคู่มือการจัดการน้ำเสียประเภทโรงพยาบาล กล่าวว่าน้ำเสียโรงพยาบาลมี ความคล้ายคลึงกับน้ำเสียซุมชน โดยจะมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์และอาจจะมีสารอันตราย ได้แก่ จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ยาที่มีองค์ประกอบที่อันตราย สารเคมีฆ่าเชื้อโรค และสารกำมันตรังสี ซึ่งเกิด จากการให้บริการผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ตรวจคนไข้นอก สถานที่ตรวจคนไข้ใน โรงซักผ้า ห้องผ่าตัด ห้องคลอด ห้องยา อาคารบ้านพัก และอาคารสถานที่อื่น ๆ ซึ่งลักษณะน้ำเสียของโรงพยาบาลส่วนใหญ่ จะมีลักษณะดังตารางที่ 2.2

ลักษณะน้ำเสีย	ช่วงความเข้มข้น	ความเข้มข้นเฉลี่ย
พีเอช	6.3-8.8	7.34
ตะกอนหนัก (มิลลิกรัมต่อลิตร)	2.0-222	60.4
ปีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร)	10.4-328	282
ทีเคเอ็น (มิลลิกรัมต่อลิตร)	5.3-44.2	18.3
สารแขวนลอย (มิลลิกรัมต่อลิตร)	1.0-375	110.8
โคลิฟอร์ม (เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร)	4.6x10 <sup>3</sup> -1.1x10 <sup>9</sup>	1.5x10 <sup>8</sup>
ฟิคัลโคลิฟอร์ม (เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร)	9.3x10 <sup>2</sup> -1.1x10 <sup>9</sup>	1.2×10 <sup>8</sup>

ตารางที่ 2.2 ลักษณะน้ำเสียทั่วไปของโรงพยาบาล

<u>หมายเหตุ</u> จากคู่มือการจัดการน้ำเสียจากอาคารปร<mark>ะเ</mark>ภทโรงพยาบาล, โดยกรมควบคุมมลพิษ, 2557

### 2.1.5.3 น้ำเสียจากโรงงานอุต<mark>สาหกร</mark>รม

เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยได้ก้าวสู่ประเทศอุตสาหกรรม และในขณะที่ เศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปัญหาสิ่งแวดล้อมก็ได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน และจากการ ที่โรงงานอุตสาหกรรมมีหลายประเภท ลักษณะน้ำเสียที่เกิดขึ้นย่อมมีความแตกต่างกัน แม้กระทั่ง โรงงานประเภทเดียวกันที่ช่วงเวลาต่างกัน อัตราการไหลที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถสรุปลักษณะน้ำเสีย ตามประเภทอุตสาหกรรมได้ดังตารางที่ 2.3

	ค่าความสกปรกของน้ำเสีย (มิลลิกรัมต่อลิตร)				
ประเภทโรงงาน	ของแข็งแขวนลอย ปีโอดี				
	ช่วง	ค่าเฉลี่ย	ช่วง	ค่าเฉลี่ย	
กระดาษ	100-1,300	830	100-1,000	530	
สบู่	100-3,000	560	200-3,000	1,180	
ผงชูรส	15m -	-	200-2,000	890	
สุรา-แอลกอฮอล์	1,000-10,000	7,800	5,000-60,000	29,000	
น้ำอัดลม	50-400	190	150-2,400	740	
นม	100-1,100	450	200-3,600	1,125	
น้ำตาล	100-600	320	200-3,900	1,320	
สิ่งทอ	0-500	160	60-900	230	
ห้องเย็น	100-700	410	250-4,000	1,560	
เครื่องกระป๋อง	100-3,000	760	500-12,700	3,560	
วุ้นเส้น	-	-	600-4,500	1,840	
เส้นหมี่	1,000-30,000	8,400	1,000-14,000	3,620	
โม่แป้ง/ แบะแซ	500-5,000	1,700	1,000-11,000	5,235	

ตารางที่ 2.3 ลักษณะน้ำเสียจากอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ

<u>หมายเหตุ</u> จากตำราระบบบำบัดมลพิษน้ำ พิมพ์ครั้งที่ 1, โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2545

### 2.1.5.4 น้ำเสียจากพื้นที่ทางการเกษตร

น้ำเสียที่เกิดจากการเกษตรที่สำคัญแบ่งออกตามลักษณะการใช้ประโยชน์ ที่ดิน ได้แก่ พื้นที่เพาะปลูก ฟาร์มเลี้ยงสุกร และบ่อเลี้ยงปลา ดังนี้

1) พื้นที่ในการเพาะปลูกเป็นพื้นที่สำคัญเนื่องจากมีเนื้อที่มากที่สุด และมีการใช้ สารเคมีมากที่สุด โดยที่มลพิษส่วนใหญ่มาจาก การใช้ปุ๋ยและสารเคมีที่ใช้ทางการเกษตร ซึ่งปุ๋ยที่ใส่ให้กับพืช จะถูกใช้ไม่หมดและตกค้างอยู่ในดินซึ่งถูกดูดซับไว้ในรูปของสารคอลลอยด์ในดิน และส่งผลกระทบต่อแหล่ง น้ำที่อยู่ใกล้เคียง โดยที่ปุ๋ยเคมีส่วนใหญ่ประกอบด้วยธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปรแตสเซียม ซึ่งเป็น ธาตุอาหารหลักของพืช และสารเคมีที่ใช้ทางการเกษตรซึ่งประกอบด้วยยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อโรค และยาฆ่า หญ้าเมื่อถูกฉีดพ่นลงในไร่นา บางส่วนจะติดอยู่ที่ใบ บางส่วนตกลงที่พื้นดิน บางส่วนถูกพัดพาไปยังที่ต่าง ๆ และเมื่อถูกชะล้างลงสู่น้ำทำให้เกิดการปนเปื้อน

2) ของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสุกรก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความสกปรกสูง ซึงของเสียที่เป็นปัญหาหลักของฟาร์มสุกร คือ ส่วนที่เป็นของแข็ง โดยส่วนมาก เป็นมูลสุกรที่เกิดจากการขับถ่าย เศษอาหาร ถุงใส่อาหาร ขวดยา และเข็มฉีดยา เป็นต้น ส่วนที่เป็นน้ำเสีย เกิดจากการล้างคอกหรือโรงเรือน น้ำล้างตัวสุกร และปัสสาวะของสุกร ทั้งนี้ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นขึ้นอยู่ กับจำนวนสุกรและลักษณะการใช้น้ำของสุกรในแต่ละราย โดยมีตัวอย่างลักษณะน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากฟาร์ม สุกร ประเภท ค มีน้ำหนักปศุสัตว์ ตั้งแต่ 6-น้อยกว่า 60 (เทียบเท่าจำนวนสุกร ตั้งแต่ 50-น้อยกว่า 500 ตัว) แสดงดังตารางที่ 2.4

3) การเพาะเลี้ยงปลา เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกฟาร์ม ซึ่งมลพิษที่เกิดขึ้นแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ มลพิษจากการเตรียมบ่อเพาะเลี้ยง มลพิษจากการให้อาหาร มลพิษจากการขับถ่าย และมลพิษจากการใช้ยารักษาโรคในสัตว์

	อัตราการใช้	2000 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	ค่า <mark>ความสกปรก</mark> ของน้ำเสีย (มิลลิกรัมต่อลิตร)			
ประเภทสุกร	น้ำ (ลิตร/ตัว/วัน)	อตราการเกดนาเลย (ลิตร/ตัว/วัน)	ารเกิดน้ำเสีย ร/ตัว/วัน) <mark>ปีโอดี</mark> ซีโอดี ของแข็งแขวนลอย		ทีเค เอ็น	
พ่อพันธุ์-แม่พันธุ์	92	64	800	1,700	900	350
สุกรขุน	48	8124JINA	3,500	7,400	4,700	700
สุกรอนุบาล	32	20	2,500	5,400	3,000	350

ตารางที่ 2.4 ลักษณะน้ำเสียที่เ<mark>กิดขึ้</mark>นจา<mark>กฟาร์มสุกร ประเภท ค จำแนกตามป</mark>ระเภทสุกรที่เลี้ยง

<u>หมายเหตุ</u> จากคู่มือวิธีการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับเลี้ยงสุกร

ประเภท ค, โดยกรมควบคุมมลพิษ, 2556

### 2.2 กระบวนการโฟโตคะตะไลซิส

### 2.2.1 หลักการและกลไกของปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิส

กระบวนการโฟโตคะตะไลซิสได้ถูกปรับปรุง พัฒนาและนำมาใช้ในงานด้าน การ บำบัดมลพิษอย่างแพร่หลายในปัจจุบันทั้งมลพิษด้านน้ำและอากาศ โดยพื้นฐานของปฏิกิริยา โฟโตคะ ตะไลซิสนั้นมาจากปฏิกิริยาโฟโตเคมี (Photochemistry) ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่ใช้แสงเป็นตัวกระตุ้น โมเลกุลของสาร ซึ่งหากการกระตุ้นด้วยแสงที่มีความยาวคลื่นที่เหมาะสม และมีตัวเร่งปฏิกิริยาใน กระบวนการจะเรียกว่า โฟโตคะตะไลซิส (Photocatalysis) และเมื่อพิจารณาจากสถานะของตัวเร่ง ปฏิกิริยาจะสามารถแบ่งโฟโตคะตะไลซิสได้เป็น 2 ประเภท คือ โฟโตคะตะไลซิสแบบสถานะเดียว (Homogeneous Photocatalysis) เป็นกระบวนการที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งมีสถานะเดียวกับสารที่ ต้องการกำจัด (โดยทั่วไปแล้วจะเป็นของเหลว) เช่น การย่อยสลายสารอินทรีย์โดยใช้ UV/H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> และโฟ โตคะตะไลซิสแบบสถานะต่าง (Heterogeneous Photocatalysis) เป็นกระบวนการที่ใช้ตัวตัวเร่ง ปฏิกิริยาซึ่งมีสถานะต่างกับสารที่ต้องการกำจัด เช่น การย่อยสลายสารอินทรีย์โดยใช้ UV/H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> และโฟ โตคะตะไลซิสแบบสถานะต่างกับสารที่ต้องการกำจัด เช่น การย่อยสลายสารอินทรีย์โดยใช้โดยใช้ UV/TiO<sub>2</sub> เป็นต้น ซึ่งในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาแบบสถานะต่าง โดยทั่วไปนั้นโมเลกุลของสารจะถูกดูดซับไว้บน ผิวของตัวเร่งปฏิกิริยา แล้วปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นที่ผิวของตัวเร่งปฏิกิริยา โมเลกุลที่ถูกดูดซับจะเกิดการ เปลี่ยนแปลงในแง่ของการจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอนและบางพันธะของโมเลกุลจะเริ่มสลาย โดย กระบวนการโฟโตคะตะไลซิสนี้จะประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ได้แก่

#### 2.2.1.1 การเกาะหรือดูดติดผิวข<mark>อง</mark>ตัวเร่งปฏิกิริยา (Adsorption Process)

กระบวนการดูดซับขอ<mark>งโม</mark>เลกุลของสารหรือคอลลอยด์ที่บริเวณที่บริเวณ

พื้นผิว หรือระหว่างผิวหน้าของตัวเร่งปฏิกิริยา ซึ่งอาจอยู่ต่างสถานะกัน เช่น ของเหลวกับของเหลว ก๊าซกับของเหลว ก๊าซกับของแข็ง หรือของเหลวกับของแข็ง โดยโมเลกุลหรือคอลลอยด์ที่ถูกดูดจับ เรียกว่า สารถูกดูดซับ (Adsorbate) ส่วนของแข็งที่มีผิวเป็นที่เกาะจับของสารถูกดูดซับ เรียกว่า สารดูด ซับ (Adsorbent) การดูดซับโมเลกุลบนผิวของสารอาจเกิดขึ้นด้วยแรงทางกายภาพ หรือด้วยแรงเคมี หรือทั้งสองอย่างร่วมกัน โดยแรงทางกายภาพ เช่น แรงแวนเดอร์วาลส์ แรงทางไฟฟ้าสถิตย์ เป็นต้น และแรงทางเคมีเป็นการสร้างพันธะเคมีขึ้นระหว่างผิวของตัวเร่งปฏิกิริยากับสารถูกดูดซับ โดยสารถูก ดูดซับไม่สามารถหลุดออกมาจากตัวเร่งปฏิกิริยาได้ ส่วนในกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส การดูดซับจะ เกิดจากแรงทางเคมีเป็นหลัก (ศรัญญา ทองอุ่น, 2555)

#### 2.2.1.2 การฉายแสง (Irradiation process)

ตัวเร่งปฏิกิริยามีทั้งที่เป็นสารตัวนำและกึ่งตัวนำจะมีแถบพลังงานอยู่ 2 แถบ คือ แถบเวเลนซ์ (valence band) เป็นแหล่งพลังงานที่มีอิเล็กตรอน (e) บรรจอยู่เต็ม และแถบการนำ ไฟฟ้า (conduction band) เป็นแหล่งพลังงานที่มีออร์บิตอลว่างอยู่ โดยสารทั้ง 2 ประเภทจะแตกต่าง กันในเรื่องของช่องว่างพลังงาน กล่าวคือ หากเป็นสารตัวนำแถบพลังงานทั้งสองจะอยู่ติดกัน ส่วนสาร กึ่งตัวนำจะมีแถบซ่องว่างพลังงาน (band gap) คั่นอยู่ระหว่างแถบพลังงานทั้งสองจะอยู่ติดกัน ส่วนสาร กึ่งตัวนำจะมีแถบซ่องว่างพลังงาน (band gap) คั่นอยู่ระหว่างแถบพลังงานทั้งสองจะอยู่ติดกัน ส่วนสาร พลังงานจะขึ้นอยู่กับชนิดของสารกึ่งตัวนำ โดยสารกึ่งตัวนำแต่ละชนิดจะมีค่าต่างกันออกไปดังรูปที่ 2.1 เมื่อสารกึ่งตัวนำที่ถูกใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาถูกกระตุ้นด้วยพลังงานแสง (แสงอัลตราไวโอเลต, UV) ที่มี พลังงานเพียงพอ หรือมีพลังงานมากกว่า หรือเท่ากับแถบช่องว่างพลังงานของสารกึ่งตัวนำ อิเล็กตรอน ในชั้นแถบเวเลนซ์ จะถูกกระตุ้นให้มีพลังงานเพิ่มขึ้นจนเคลื่อนที่เข้าสู่ชั้นแถบการนำไฟฟ้า ทำให้เกิดที่ ว่างของอิเล็กตรอน (hole, h<sup>+</sup>) ในชั้นแถบเวเลนซ์ กลายเป็นคู่ของอิเล็กตรอนและที่ว่างของอิเล็กตรอน (e<sup>-</sup>/h<sup>+</sup>) ในอนุภาคตัวเร่งปฏิกิริยา ดังรูปที่ 2.2 ในกรณีที่ไม่มีตัวรับอิเล็กตรอนหรือตัวให้อิเล็กตรอนใน ระบบ อิเล็กตรอนที่ถูกกระตุ้นให้มีพลังงานเพิ่มมากขึ้นนี้ สามารถรวมตัวกับที่ว่างของอิเล็กตรอนในระบบ อิเล็กตรอนและที่ว่างของอิเล็กตรอนจะมีบทบาทในกรณีที่มีตัวให้หรือตัวรับอิเล็กตรอนในระบบ อิเล็กตรอนและที่ว่างของอิเล็กตรอนจะมีบทบาทในกรดงิจไม่ดีม



รูปที่ 2.1 ค่าช่องว่างของพลังงานของสารกึ่งตัวนำชนิดต่าง ๆ ที่พีเอช 1 (Gratzel, 2001)



รูปที่ 2.2 การเกิดอิเล็กตรอน (e<sup>-</sup>) และที่ว่างของอิเล็กตรอน (hole: h<sup>+</sup>)ในปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิส ดัดแปลงจาก (Ahmed, Rasul, Brown, and Hashib, 2011)

กลไกของปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิส (Mechanism of Photocatalysis Reaction) (Herrmann, 2010) ที่เกิดขึ้นเป็นดังนี้

$$H_2 O \rightarrow H^+ + O H^-$$
 (2.18)

การกระตุ้นด้วยแสง

 $Catalyst + hV \rightarrow e_{CB}^{-} + h_{VB}^{+}$ (2.19)

การเกิดเรดิคอล จาก  $e^-_{CB}$  ,  $h^+_{VB}$ 

 $H^+ + O_2^- \rightarrow HO_2^-$ 

 $h^+_{VB} + OH^- \rightarrow OH$  (2.20)

$$e_{CB}^{-} + O_2 \rightarrow O_2^{-}$$
 (2.21)

$$H^{+} + e^{-}_{CB} \rightarrow H_{\bullet}$$
 (2.23)

การรวมตัวกันใหม่ของ e<sup>-</sup> , h<sup>+</sup> (electron-hole recombination)

$$e^-_{CB} + h^+_{VB} \rightarrow Heat$$

(2.24)

(2.22)

#### 2.3 ตัวเร่งปฏิกิริยาและการสังเค<mark>ราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา</mark>

ตัวเร่งปฏิกิริยาถือเป็นส่วนประกอบหลักของกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส เนื่องจากตัวเร่ง ปฏิกิริยาแต่ละชนิดจะเหมาะสมกับแสงที่ความยาวคลื่นแตกต่างกันไป อีกทั้งปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นใน กระบวนการโฟโตคะตะไลซิสยังแตกต่างกัน ดังนั้นการเข้าใจหลักการและการเลือกตัวเร่งปฏิกิริยาที่ เหมาะสมในกระบวนการโฟโตคะตะไลซิสจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ถูกนำมาใช้ในกระบวนการโฟโตคะตะไลซิสมีหลายชนิด ได้แก่ โลหะแทนซิชัน (transition metal) เช่น ทองแดง โครเมียม นิเกิล เป็นต้น แต่ที่นิยมใช้กันมากคือวัสดุกึ่งตัวนำ (semiconductor) เช่น ไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO<sub>2</sub>) แคดเมียมซัลไฟด์ (CdS) ทังสเตนออกไซด์ (WO<sub>3</sub>) และซิงค์ออกไซด์ (ZnO) เป็นต้น เนื่องจากมีโครงสร้างทางไฟฟ้าที่เหมาะสมในการเกิดอิเล็กตรอนและที่ ว่างของอิเล็กตรอน ซึ่งทำให้สามารถใช้ประโยชน์ในการเกิดปฏิกิริยาต่าง ๆ ได้ ซึ่งซิงค์ออกไซด์เป็น ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีแถบของช่องว่างพลังงานที่กว้างเมื่อ เปรียบเทียบกับสารกึ่งตัวนำอื่น ๆ มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นตัวดูดซับสารอินทรีย์ที่ดี โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์เหมาะที่จะทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันสารอินทรีย์ และสามารถรีดักชัน ออกซิเจนได้ในขณะเดียวกัน อีกทั้งราคาค่อนข้างถูกเมื่อเปรียบเทียบกับสารกึ่งตัวนำชนิดอื่น โดยการ สังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยามีหลายวิธีด้วยกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของลักษณะการนำไปใช้งาน ซึ่งซิงค์อ อกไซด์สามารถสามารถสังเคราะห์ได้โดยวิธีต่าง ๆ เช่น โซล-เจล (sol gel) ไฮโดรเทอร์มอล (hydrothermal) การปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต (electrospining) การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ ขั้วไฟฟ้าแอโนด (anodic oxidation) การแอโนไดเซชัน (Anodization) และการสปัตเตอริง (Sputtering) เป็นต้น จากขั้นตอนการสังเคราะห์ที่มีหลากหลายวิธีนั้นนำมาซึ่งวัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์ที่ มีโครงสร้าง คุณลักษณะแบบต่าง ๆ เช่น ลวดนาโน (Nanowires) เข็มขัดนาโน (nanobelt) ท่อนาโน (nanotubes) ดอกไม้นาโน (nanoflower) ขดเป็นชั้นนาโน (nanorings) ใบพัดนาโน(nanopropeller) าลฯ (He et al., 2010) ในที่นี้จะกล่าวถึงเพียงการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยกระบวนการแอนโนได เซชันและสปัตเตอริงเท่านั้น ซึ่งหลักการมีดังนี้

### 2.3.1 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยกระบวนการแอโนไดเซชัน

กระบวนการแอโนไดเซชันเป็นเทคนิคการทำให้เกิดออกไซด์บนพื้นผิวของโลหะโดยใช้ การให้ความต่างศักย์ไฟฟ้าแก่โลหะ (Working Electrode) ที่มีผิวสัมผัสกับสารละลายที่นำไฟฟ้าได้ (Electrolyte) กระบวนการนี้ถูกคิดค้นโดย Bengough-Stuart ในปี 1923 (Wernick et al. 1987) เริ่มแรกได้ทดลองใช้อะลูมิเนียมเป็นวัสดุปลูก (Substrate) ชั้นอะลูมิเนียมออกไซด์ที่ถูกสร้างขึ้นนี้ ประกอบด้วยส่วนแรกคือ ชั้นออกไซด์ที่มีความบางมีลักษณะเนื้อแน่น (Compact) เรียกว่า ชั้น Barrier ซึ่งชั้น Barrier มีความหนาประมาณ 0.1-2.0 % ของความหนาทั้งหมดของชั้นออกไซด์ ขึ้นอยู่กับความ เข้มข้นของสารละลายและค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ใช้ และส่วนที่สอง ได้แก่ ชั้นออกไซด์ที่มีรูพรุนมีเส้น ผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก และจะเห็นได้ว่ามีการก่อตัวเป็นท่อซึ่งมีผนังท่อ (Cell wall) ให้เห็นได้ ดัง แสดงในรูปที่ 2.3



รูปที่ 2.3 เซลล์โครงสร้างหกเหลี่ยมของชั้นอะลูมิเนียมออกไซด์ (Wernick et al. 1987)

Mor et al. (2006) ได้เสนอว่าการก่อตัวของอะลูมิเนียมออกไซด์ที่มีรูพรุนนี้มีลักษณะ เช่นเดียวกันและเป็นพื้นฐานของการก่อตัวของไทเทเนียมไดออกไซด์รูปท่อขนาดนาโน (TiO<sub>2</sub> nanotubes) กระบวนการแอโนไดเซชันเริ่มด้วยการเริ่มก่อตัวของชั้นออกไซด์บนผิวโลหะไทเทเนียม ซึ่ง เป็นผลมาจากปฏิกิริยาระหว่างไทเทเนียมไอออน (Ti<sup>4+</sup>) กับออกซิเจนไอออน (O<sup>2-</sup>) ในสารละลาย ซึ่ง ปฏิกิริยาโดยรวมสามารถแสดงในสมการที่ 2.25 และ 2.26
$$2H_2O \rightarrow O_2 + 4e^- + 4H^+ \tag{2.25}$$

$$Ti + O_2 \rightarrow TiO_2$$
 (2.26)

ในช่วงแรกของกระบวนการแอโนไดเซชัน แรงขับเคลื่อนของความต่างศักย์ไฟฟ้ามี มากกว่าการกัดกร่อนด้วยสารละลายเนื่องจากสนามไฟฟ้าที่ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับความหนาของชั้น ออกไซด์และต่อมารูเล็ก ๆ ค่อย ๆ เกิดขึ้นบนชั้นออกไซด์เนื่องจากการกัดกร่อนด้วยสารละลาย (สารละลายที่ประกอบด้วยฟลูออไรด์ไอออน) ทำให้เกิดการก่อตัวของรูพรุนดังสมการที่ 8.13 และรูเล็ก ๆ เหล่านี้ก็ค่อย ๆ ขยายใหญ่ขึ้นเป็นรูขนาดใหญ่และความหนาแน่นของรูพรุนเหล่านี้ก็เพิ่มขึ้นจนทั่ว พื้นผิวโลหะ ไดอะแกรมการพัฒนาของไทเทเนียมรูปท่อขนาดนาโน (TiO<sub>2</sub> nanotubes) แสดงดังรูปที่ 2.27

$$TiO_2 + 6F^- + 4H^+ \rightarrow TiF_6^{2^-} + 2H_2O$$
 (2.27)



รูปที่ 2.4 ไดอะแกรมการพัฒนาของไทเทเนียมรูปท่อขนาดนาโน (TiO<sub>2</sub> nanotubes) (Mor et al. 2006)

- (ก) การก่อตัวของชั้นออกไซด์ (ข) การเริ่มเกิดรูพรุนเล็กๆ บนชั้นออกไซด์
- (ค) การเกิดชั้น Barrier (ง) การขยายขนาดของรูพรุนและเกิดเป็นผนังท่อ
- (จ) การพัฒนาอย่างสมบูรณ์ของไทเทเนียมรูปท่อขนาดนาโน (TiO<sub>2</sub> nanotubes)

สัญญาณพัลส์เป็นปรากฎการณ์ที่เกิดจากระดับสัญญาณไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงจากระดับ หนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งที่มีความแตกต่างกันระหว่างแรงดันต่ำสุดกับแรงดันสูงสุดอย่างรวดเร็ว อาจมี ความต่อเนื่องหรือไม่ก็ได้ แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ สัญญาณพัลส์บวก และสัญญาณพัลส์ลบ แสดงดังรูปที่ 2.5 (กรกฏ ชูเจริญ, 2554)



รูปที่ 2.6 ส่วนประกอบของสัญญาณพัลส์

ส่วนประกอบของสัญญาณพัลส์ แสดงได้ดังรูปที่ 2.6 ซึ่งประกอบได้ด้วยส่วนที่สำคัญดังนี้ **1) ขนาดของพัลส์** (Pulse amplitude) หมายถึง ค่าที่วัดจากระดับแรงดันศูนย์ ไปถึงค่าสูงสุด (Peak value)

ขอบขาของพัลส์ (Edge) มี 2 ลักษณะ

ขอบขาขึ้นของพัลส์ (Leading edge or rising edge or positive – going edge) หมายถึง ค่าของสัญญาณที่เปลี่ยนค่าจากระดับแรงดันต่ำไประดับแรงดันสูงสุด พิจารณา ที่เวลา t = 0

ขอบขาลงของพัลส์ (Trailing edge or falling edge or negative – going edge) หมายถึง ค่าของสัญญาณที่เปลี่ยนค่าจากระดับแรงดันสูงสุดไปสู่ระดับต่ำสุดของพัลส์

3) ความกว้างของพัลส์ (Pulse Width of PW) หมายถึง ช่วงเวลาที่วัดจาก ขอบขาขึ้นของพัลส์จนถึงขอบขาลงของพัลส์

4) ช่องว่างของพัลส์ (Space Width of SW) หมายถึง ช่วงเวลาที่วัดจากขอบ ขาลงของพัลส์ในรูปคลื่นแรกจนถึงขอบขาขึ้นในรูปคลื่นถัดไป

5) คาบของเวลาพัลส์ (Time period of T) หมายถึง ระยะเวลาที่วัดจาก ขอบขาขึ้นของพัลส์ที่เวลา t = 0 จนถึงขอบขาขึ้นของพัลส์รูปคลื่นต่อไป

6) ความถี่ของพัลส์ (Pulse Repetition Frequency or F) หมายถึง ค่า ส่วนกลับของเวลา

นอกจากตัวเร่งปฏิกิริยา TiO<sub>2</sub> ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการแอโนไดเซชันแล้ว ตัวเร่งปฏิกิริยาตัวอื่น ๆ เช่น WO<sub>3</sub> ZnO เป็นต้น ก็ยังสามารถสังเคราะห์ได้ด้วยวิธีการเดียวกันนี้ แต่ ลักษณะพื้นผิวออกไซด์ที่เกิดขึ้นจะมีแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับธรรมชาติของวัสดุแต่ละชนิด และ สภาวะที่ใช้ในกระบวนการแอโนไดเซชันด้วย เช่น pH ชนิดของสารละลายอิเล็กโตรไลท์ และความ เข้มข้นของสาร เป็นต้น

#### 2.3.2 การสังเครา<mark>ะห์ตัวเร่</mark>งปฏิกิริยาด้วยกระบวนการ<mark>สปัตเตอ</mark>ริง

กระบวนการสปัตเตอริง (sputtering) เป็นเทคนิคเคลือบทางฟิสิกส์อย่างหนึ่ง ที่ เกิดขึ้นเมื่อผิวหน้าของวัสดุ ถูกซนด้วยอนุภาคพลังงานสูงจนอนุภาคของวัสดุที่อยู่ผิวหน้าของวัสดุนั้น ๆ เกิดการหลุดออกมา กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นจากการถ่ายทอดโมเมนตัมของอนุภาคพลังงานสูงที่วิ่งเข้า ชนกับอนุภาคของวัสดุที่ถูกชน ทำให้อะตอมที่ผิวสารเคลือบหลุดออกมาแล้วไปเคลือบบนแผ่น ฐานรองรับ โดยการเคลือบฟิล์มบางด้วยกระบวนการสปัตเตอริงนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 วิธี คือ วิธีดีซี สปัตเตอริง (DC Sputtering) และวิธีอาร์เอฟสปัตเตอริง (RF Sputtering) ดังนี้

2.3.2.1 วิธีดีซีสปัตเตอริง (DC Sputtering)

การเคลือบฟิล์มบางด้วยวิธีดีซีสปัตเตอริง เป็นกระบวนการเคลือบฟิล์มโดยใช้ไฟฟ้า กระแสตรง ซึ่งระบบสปัตเตอริงจะประกอบไปด้วยคู่ของขั้วไฟฟ้าแบบระนาบ แสดงดังรูปที่ 2.7



รูปที่ 2.7 ระบ<mark>บด</mark>ีซีสปัตเตอริง

โดยขั้วไฟฟ้าหนึ่งเป็นแคโทดเย็น (cold cathode) ที่ผิวหน้าของแคโทดจะถูกปิดด้วย สารที่เป็นเป้า (target) ที่จะเป็นสารเคลือบ และอีกขั้วหนึ่งเป็นแอโนด (anode) ซึ่งจะมีส่วนของชิ้นงาน ที่ต้องการเคลือบจะวางอยู่ มีอุปกรณ์ทำความร้อนอยู่ด้านล่างเพื่อใช้เพิ่มอุณหภูมิให้แก่ฐานในขณะ เคลือบชั้นฟิล์ม ภายในห้องเคลือบ (chamber) จะถูกดูดอากาศออกจนมีสภาวะสุญญากาศ จากนั้นจะ ถูกเติมด้วยก๊าซเฉื่อยโดยใช้ความดันก๊าซต่ำ ซึ่งก๊าซเฉื่อยมักจะใช้ก๊าซอาร์กอนเนื่องจากเป็นธาตุที่มี น้ำหนักอะตอมค่อนข้างมากจึงเหมาะแก่การระดมยิ่งเป้าสารเคลือบ เมื่อให้เริ่มให้ความต่างศักย์ระหว่าง ขั้วแคโทดและแอโนดในช่วงที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำ อิเล็กตรอนที่อยู่ระหว่างขั้วไฟฟ้าจะมีพลังงานสูงไม่เพียง พอที่จะไอออไนซ์อะตอนของก๊าซได้ และเมื่อความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงขึ้นอิเล็กตรอนที่ถูกเร่งภายใต้ สนามไฟฟ้าจะมีพลังงานสูงขึ้นจนสามารถชนกับอะตอมของก๊าซเฉื่อยและจะถ่ายโอนพลังงานให้กับ อะตอมของก๊าซเฉื่อย (A) ทำให้ก๊าซเฉื่อยแตกตัวเป็นไอออนบวก (A<sup>+</sup>) และอิเล็กตรอน (e<sup>-</sup>) เรียกว่า สภาวะพลาสม่า ดังสมการที่ 2.28

 $e^{-} + A \rightarrow 2e^{-} + A^{+}$   $A^{+}$   $A^{+}$ 

อิเล็กตรอน 2 ตัวที่เกิดขึ้นจะถูกเร่งภายใต้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าไปยังขั้วแอโนดและชน กันกับอะตอมของก๊าซเฉื่อย 2 ตัว เป็นการเพิ่มจำนวนไอออนและอิเล็กตรอน ในขณะเดียวกันไอออน บวกจะถูกเร่งเข้าชนขั้วแคโทดเกิดการปล่อยอิเล็กตรอนชุดที่ 2 (secondary electron) เรียกว่า กระบวนการอะวาลานซ์ (avalanche) การชนกันระหว่างอิเล็กตรอนกับอะตอมก๊าซเฉื่อยจะเกิดขึ้น อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมีปริมาณไอออนและอิเล็กตรอนคงที่ และรักษาสภาพสมดุลของการดิสชาร์จได้ โดยไม่ต้องอาศัยแหล่งกำเนิดจากภายนอก เรียกกระบวนการช่วงนี้ว่าทาวน์เซนด์ดิสชาร์จ (townsend discharge) จากนั้นกระแสดิสชาร์จจะมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงค่า ๆ หนึ่งจึงเริ่มเกิดการเรืองแสงขึ้น เรียกว่าดีซีโกลว์ดิสชาร์จ (DC glow discharge) แรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมจะมีค่าลดลงค่ายีลด์จะต่ำ ในช่วงเริ่มต้นของการเรืองแสง การชนกันของไอออนบนแคโทดจะเกิดขึ้นในบางบริเวณและมีความไม่ สม่ำเสมอ ความเข้มของการเรืองแสงจะเกิดขึ้นตามแนวหรือมุมของแคโทดที่มีสนามไฟฟ้าสูง เมื่อ กระแสไฟฟ้ามีค่าเพิ่มขึ้นแนวการชนของไอออนจะค่อย ๆ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจนครอบคลุมเต็มพื้นที่ของ แคโทดจนกระทั่งมีความหนาแน่นของกระแสสม่ำเสมอและแรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วอิเล็กโทรดจะคงที่ ด้วย จากนั้นการเพิ่มกำลังไฟฟ้าเข้าสู่ระบบจะทำให้ทั้งแรงดันและกระแสไฟฟ้ามีค่าเพิ่มขึ้น การเรือง แสงจะเปล่งจ้าขึ้น ซึ่งเป็นช่วงที่นิยมใช้ในระบบสปัตเตอริง ในช่วงขณะนี้ถ้าไม่มีการระบายความร้อน ให้กับแคโทด เมื่อความหนาแน่นของกระแสแคโทดเพิ่มขึ้นสูงประมาณ 0.1 แอมป์ต่อตารางเซนติเมตร ความร้อนที่เกิดขึ้นจากการชนกันของไอออนบวกบนผิวแคโทดจะเกิดขึ้นมากจนเกิดกระบวนการ ปลดปล่อยอิเล็กตรอนแบบเทอร์มิอนิค (thermionic electron emission) เสริมกับการปลดปล่อย อิเล็กตรอนชุดที่สองและกระบวนการอะวาลานซ์ ทำให้ความนำไฟฟ้าของก๊าซในระบบสูงขึ้นอย่าง รวดเร็ว แรงดันไฟฟ้าระหว่างอิเล็กโทรดจะตกลงมากในขณะที่กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นสูงและเกิดการ เปล่งแสงประกายจ้าของการอาร์ค (arc discharge) (พนม กาศรุณ, 2550 และ กิตติพงษ์ ลิ้มวิเชียร, 2554)

#### 2.3.2.2 วิธีอาร์เอฟสปัตเตอริ<mark>ง (RF S</mark>puttering)

การเคลือบฟิล์มบางด้วยวิธีอาร์เอฟสปัตเตอริงเป็นกระบวนการเคลือบโดย จ่ายไฟฟ้ากระแสสลับความถี่สูงให้กับขั้วแคโทดและขั้วแอโนด ดังรูปที่ 2.8 โดยทั่วไปความถี่วิทยุที่ใช้ใน วิธีนี้จะอยู่ในช่วง 5 – 30 เมกกะเฮิร์ต (MHz) ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับความถี่ในช่วง 13.56 – 40.80 เมกกะ เฮิร์ต เป็นค่าความถี่ที่คณะกรรมการ FCC (Federal Communications Commission) กำหนดไว้สำหรับ ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับพลาสม่า เพื่อไม่ให้รบกวนการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ และเป็นความถี่ที่ให้ อัตราการไอออไนซ์สูง โดยในกระบวนการอาร์เอฟสปัตเตอริงจะต้องทำให้อิเล็กตรอนที่หลุดจากขั้ว แคโทดมีพลังงานที่สูงพอที่จะทำให้เกิดการไอออไนซ์ก๊าซในห้องเคลือบ ดังสมการ 2.28 เช่นเดียวกับ ระบบดีซีสปัตเตอริง และเกิดการกระเจิงของอะตอมเป้าสารเคลือบ แล้วตกลงบนแผ่นรองรับ โดยที่การ เคลือบฟิล์มในช่วงครึ่งรอบแรกซึ่งมีศักย์ไฟฟ้าที่เป็นบวก จะเกิดการเคลือบบนแผ่นรองรับ แต่ในช่วง ครึ่งรอบหลังซึ่งมีศักย์ไฟฟ้าที่เป็นอบ แผ่นฟิล์มที่เคลือบบางส่วนจะถูกสปัตเตอร์หลุดออกแต่น้อยกว่า การเคลือบในครึ่งรอบแรกที่เป็นบวก จึงเกิดกระบวนการเคลือบและหลุดออกสลับกันเพื่อลดปริมาณการ ปนเปื้อน (contamination) ของฟิล์มเคลือบบนแผ่นรอบรับ ฟิล์มบางจึงมีความบริสุทธิ์สูง มีความ หนาแน่นสม่ำเสมอ และคงทน (อดุล ดีอราแม, 2554) สามารถผลิตไอออนหรืออะตอมในอัตราที่สูงเมื่อ เปรียบเทียบกับระบบดีซีสปัตเตอริงที่ใช้กำลังไฟฟ้าเท่ากัน นอกจากนั้นยังสามารถใช้กับเป้าที่มีคุณสมบัติ เป็นฉนวนได้ (นิยม โฮ่งสิทธิ์, 2548)



รูปที่ 2.8 ระบ<mark>บอาร์เอ</mark>ฟสปัตเตอริง

#### 2.3.2.3 ระบบเมกนีตรอนสปั<mark>ต</mark>เตอริง (Magnetron Sputtering)

แมกนีตรอนสปัตเตอริงเป็นการใส่สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าไปในระบบ ดังรูปที่ 2.9 เพื่อเพิ่มปริมาณไอออน โดยเพิ่มระยะทางในการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุ เนื่องจากแรงลอร์ เลนซ์ทำให้อนุภาคมีการเคลื่อนตัวเป็นเกลียวหรือเป็นวงกลม เมื่ออนุภาคเคลื่อนที่ทำมุมกับ สนามแม่เหล็ก ทำให้อนุภาคมีโอกาสที่จะไปชนกับอนุภาคอื่น ๆ มากขึ้น จึงเพิ่มอัตราการเคลือบฟิล์ม ได้มากถึง 10-100 เท่า และช่วยลดความดันของก๊าซเนื่อยเมื่อทำการเคลือบได้มาก ทำให้ฟิล์มที่เคลือบ ได้มีความสะอาดสูง จึงเป็นที่นิยมแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งเมกนีตรอนสปัตเตอริงสามารถนำไปใช้ได้ทั้ง ในระบบกระแสตรงและกระแสสลับ ถ้าในระบบกระแสตรง เรียก ดีซีเมกนีตรอนสปัตเตอริง (DC Magnetron Sputtering) และกระแสสลับเรียกอาร์เอฟเมกนีตรอนสปัตเตอริง (RF Magnetron Sputtering) โดยที่สนามแม่เหล็กที่ใช้ในระบบแมกนิตรอนสปัตเตอริงมี 2แบบถ้าสนามแม่เหล็กมีทิศ ขนานกับสนามไฟฟ้า เรียกว่า สนามตามยาว (longitudinal field) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการเพิ่ม ปริมาณไอออนไม่สูง แต่สามารถเคลือบฟิล์มได้สม่ำเสมอ และไม่ทำให้แนวการเกิดโกลว์ดิสชาร์จ เปลี่ยนแปลงไป ถ้าสนามแม่เหล็กมีทิศตั้งฉากกับสนามไฟฟ้า เรียกว่า สนามตามขวาง (transverse field) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการเพิ่มปริมาณไอออนดีกว่าสนามตามยาว และเป็นวิธีที่นิยมใช้ในการ เคลือบฟิล์ม



รูปที่ 2.9 ระบบแม<mark>กนี</mark>ตรอนสปัตเตอริง

#### 2.4 กระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส (Photoelectrocatalysis)

กระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส คือ การนำกระบวนการโฟโตคะตะไลซิสมาประยุกต์เข้า กับเซลล์ไฟฟ้าแบบ 3 ขั้ว กล่าวคือ มีการให้พลังงานจากแสงจากแหล่งกำเนิดแสงภายนอก เช่น แสงอัล ตราไวโอเล็ต แก่ตัวตัวเร่งปฏิกิริยา เพื่อกระตุ้นทำให้เกิดการอิเล็กตรอนและที่ว่างของอิเล็กตรอน และ ในที่สุดจะเกิดเรดิคอลที่มีความสามารถในการออกซิไดซ์สารอินทรีย์ได้ และเมื่อต่อเข้ากับเซลล์ไฟฟ้า แบบ 3 ขั้ว ซึ่งจะมีการจ่ายความต่างศักย์ให้กับขั้วไฟฟ้าใช้งานด้วยเพื่อช่วยให้การออกซิไดซ์สารอินทรีย์ เป็นไปอย่างสมบูรณ์มากขึ้น และสามารถวัดค่าความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและความต่างศักย์ของ เซลล์ไฟฟ้าที่อยู่ในสารละลายได้อีกด้วย ซึ่งแสดงได้ดังรูปที่ 2.10



รูปที่ 2.10 กระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส

#### 2.4.1 ไฟฟ้าเคมี (Electrochemistry)

ไฟฟ้าเคมี เป็นความสัมพันธ์ระหว่างปฏิกิริยาเคมีและพลังงานไฟฟ้า หลักการของ เคมีไฟฟ้าได้ถูกประยุกต์นำไปใช้งานด้านต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การศึกษาปรากฏการณ์กัดกร่อน การศึกษากลไกและจลศาสตร์ของปฏิกิริยาการสังเคราะห์สารอินทรีย์และอนินทรีย์ด้วยไฟฟ้า และการ ใช้หลักการเคมีไฟฟ้าในทางเคมีวิเคราะห์ เป็นต้น ซึ่งกระบวนการทางไฟฟ้าเคมีจะเกิดจากการถ่ายโอน อิเล็กตรอนจากสารหนึ่งไปยังสารหนึ่ง และเมื่อมีการถ่ายโอนอิเล็กตรอน ปฏิกิริยาเคมีก็จะสามารถทำ ให้เกิดพลังงานไฟฟ้าได้ ในทำนองกลับกันพลังงานไฟฟ้าก็สามารถทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีได้เช่นกัน ปฏิกิริยาที่มีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนนี้เรียกว่า ปฏิกิริยารีดอกซ์ (redox reaction) ซึ่งประกอบด้วย ปฏิกิริยาออกซิเดชัน (oxidation) และรีดักชัน (reduction) กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า ไฟฟ้าเคมี เป็น ศาสตร์ ของปฏิกิริยาที่ผิวหน้าสัมผัสของวัสดุตัวนำ (conductor material) ซึ่งเป็นอิเล็กโทรด (electrode) ที่อาจเป็นโลหะ หรือสารกึ่งตัวนำ อย่างเช่น กราไฟต์ (graphite) และไอออนิกคอนดัก เตอร์อิเล็กโทรไลต์ (electrolyte)

#### 2.4.1.1 เซลล์ไฟฟ้าเคมี (Ele<mark>ctroch</mark>emical cell)

หลักการของเซลล์ไฟฟ้าเคมี คือ การเปลี่ยนจากพลังงานเคมีเป็นพลังงาน ไฟฟ้า โดยในเซลล์ไฟฟ้าเคมี 1 เซลล์ต้องประกอบไปด้วยขั้วไฟฟ้าอย่างน้อย 2 ขั้ว จุ่มลงในสารละลาย อิเล็กโทรไลต์ชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันก็ได้ โดยมีตัวอย่างของเซลล์ไฟฟ้าเคมีแสดงดังรูปที่ 2.11 เมื่อ นำแผ่นสังกะสีและแผ่นทองแดงจุ่มลงในสารละลายกรดซัลฟิวริกเจือจาง สังกะสีและทองแดงจะแตกตัว เป็นไอออน โดยที่สังกะสีสามารถแตกตัวและให้อิเล็กตรอนได้ดีกว่าทองแดงจึงมีศักย์ไฟฟ้าต่ำกว่า ส่วน ทองแดงซึ่งสามารถแตกตัวและให้อิเล็กตรอนได้น้อยกว่าจึงมีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่า ทำให้อิเล็กตรอนไหลจาก ขั้วที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำไปยังขั้วที่มีศักย์ไฟฟ้าสูง (จากขั้วสังกะสีไปสู่ขั้วทองแดง) แล้วจึงเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น เช่น เซลล์กัลป์วานิก (Galvanic cell) เซลล์วอลเตอิก (Voltaic cell) เป็นต้น



รูปที่ 2.11 เซลล์ไฟฟ้าเคมีทองแดงและสังกะสี

#### 2.4.1.2 อิเล็กโตรไลซิส (Electrolysis)

อิเล็กโตรไลซิส คือ กระบวนการผ่านกระแสไฟฟ้าตรง (D.C.) จากภายนอก เข้าไปในสารละลาย อิเล็กโทรไลต์ แล้วทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมี ตัวอย่างเช่น การชุบโลหะ (ขบวนการที่ ผ่านกระแสไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมี) เครื่องมือที่ใช้แยกสารละลายด้วยไฟฟ้าเรียกว่า อิเล็กโตรไลซิส เซลล์ เช่น เซลล์ไฟฟ้าหรือ แบตเตอรี่ ประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ แหล่งพลังงานไฟฟ้าจาก ภายนอก ขั้วไฟฟ้า และสารละลายอิเล็กโทรไลต์

เซลล์ไฟฟ้าแบบ 3 ขั้ว (three-electrode cell) เป็นอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับ การวิเคราะห์เชิงปริมาณเกี่ยวกับสมบัติสารกัดกร่อนของวัสดุต่าง ๆ ซึ่งอุปกรณ์นี้จะถูกใช้ได้ในหลาย รูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการกัดกร่อน แต่ก็สามารถนำมาใช้วัดค่าความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและความ ต่างศักย์ของเซลล์ไฟฟ้าที่อยู่ในสารละลายได้เช่นกัน โดยส่วนประกอบของเซลล์ไฟฟ้าชนิดนี้แสดงดังรูป ที่ 2.12



รูปที่ 2.12 เซลล์ไฟฟ้าแบบ 3 ชั้ว (three-electrode cell)

 ขั้วไฟฟ้าใช้งาน (Working electrode) เป็นชื่อสำหรับใช้เรียก ขั้วไฟฟ้าที่จะถูกวัดค่าต่าง ๆ โดยปกติแล้วขั้วไฟฟ้าใช้งานนี้จะต้องมีพื้นที่ประมาณ 1 ตารางเซนติเมตร เพื่อความสะดวกในการใช้งาน โดยสามารถแปลงค่ากระแส (Measured current) ที่วัดได้ไปเป็นความ หนาแน่นของกระแสไฟฟ้า (Current density) ได้เลย แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีขนาดเท่ากับ 1 ตาราง เซนติเมตรก็ได้ ขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นงานที่สามารถเตรียมได้และจำเป็นต้องใช้ในแต่ละประเภทงาน สำหรับการเตรียมขั้วไฟฟ้าใช้งานสามารถเตรียมได้หลายวิธี โดยวิธีที่ง่ายที่สุด คือ การติดชิ้นงานลงบน ฐานรองที่ทำด้วยเรซินที่ทนทานต่อสารละลายที่ใช้ และต่อสายไฟออกมายังวงจรภายนอก เมื่อ เกิดปฏิกิริยาเคมีและมีอิเล็กตรอนเกิดขึ้นในขั้ว อิเล็กตรอนนั้นก็จะถูกขับด้วยแหล่งจ่ายพลังงาน (Power Source) ไปยังขั้วไฟฟ้าร่วม ทำให้เกิดการครบวงจรและเกิดเป็นกระแสที่สามารถวัดได้ด้วย แอมป์มิเตอร์ ซึ่งกระแสที่วัดได้นี้จะเป็นตัวแทนของกระแสหรืออิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาใน สารละลาย

2) ขั้วไฟฟ้าร่วม (Counter electrode) เป็นชื่อที่ใช้เรียกขั้วไฟฟ้าอีก ประเภทหนึ่งที่ใช้ในเทคนิคนี้ โดยขั้วไฟฟ้านี้จะถูกออกแบบให้กระแสที่เกิดขึ้นในวงจรไหลผ่านได้และถูก วัดออกมา ซึ่งจะไม่พิจารณาความต่างศักย์ที่เกิดขึ้นระหว่างขั้วไฟฟ้าชนิดนี้กับขั้วไฟฟ้าใช้งาน โดยทั่วไป แล้วจะนิยมใช้แท่งคาร์บอน (Carbon rod) แต่สามารถใช้วัสดุอื่น ๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดการเจือปนของ ไอออนในสารละลายแทนได้เช่นกัน ซึ่งแพลทินัม และทองคำเป็นที่นิยมนำมาใช้เช่นกัน รวมทั้ง ไทเทเนียมด้วย

ขั้วไฟฟ้าอ้างอิง (Reference electrode) โดยทั่วไปแล้วการทดลอง 3) ด้วยเทคนิคนี้จะนิยมใช้ขั้วไฟฟ้าคาโลเมลอิ่มตัว (Saturated calomel electrode, SCE) หรือขั้วไฟฟ้า ้อิเล็กโทรดแบบซิลเวอร์/ซิลเวอร์คลอไรด์ (Ag/AgC<mark>l) เ</mark>ป็นขั้วไฟฟ้าอ้างอิง โดยขั้วอ้างอิงนี้จะมีลวดเงินต่อ ้กับซิลเวอร์คลอไรด์และจุ่มซิลเวอร์คลอไรด์ลงใน KCl ชนิดอิ่มตัว KCl นี้จะซึมผ่านรูเล็ก ๆ ที่ปลายของ หลอดแก้วเพื่อสัมผัสกับสารละลายที่จะวัด กา<mark>รเชื่อม</mark>ต่อระหว่างสารละลายทั้งสองนี้ เรียกว่า salt bridge รูที่เชื่อมต่อนี้มักจะมีสารเอสเบสตอสหรื<mark>อ</mark>เซรามิก วางคั่นเอาไว้ เพื่อทำให้การไหลของ KCl คงที่ ตลอดเวลาขณะทำการวัด ขั้วไฟฟ้าประเภทนี้ถู<mark>ก</mark>สร้างขึ้<mark>นเ</mark>พื่อสร้างความเสถียรให้กับการวัดค่าความต่าง ้ศักย์ในระบบ เนื่องจากเมื่อเกิดปฏิกิริยาที่ชั<mark>้วไฟ</mark>ฟ้าใช้งา<mark>นแ</mark>ละขั้วไฟฟ้าร่วมจะเกิดค่าความต่างศักย์ตก ้คร่อมขั้วไฟฟ้าทั้งสอง ทำให้การวัดค่าความ<mark>ต่า</mark>งศักย์บริเว<mark>ณนี้</mark>มีความคลาดเคลื่อน ดังนั้นการใช้ขั้วไฟฟ้า ้อ้างอิงที่วัดเฉพาะความต่างศักย์ของไ<mark>อออ</mark>นที่เกิดขึ้นในสารล<mark>ะล</mark>ายแทนการวัดโดยตรงที่ขั้วทั้งสองจะ ้ช่วยลดค่าความคลาดเคลื่อนได้ โดย<mark>ขั้วไฟ</mark>ฟ้านี้จ**ะต้อ**งไม่มีกระ<mark>แสท</mark>ี่เกิดขึ้นจากขั้วไฟฟ้าใช้งานไหลผ่าน ้ถ้ามีกระแสจากขั้วไฟฟ้าใช้งานไหล<sub>ี</sub>ผ่านจะทำให้ค่าความต่างศักย์ที่วัดได้ไม่คงที่ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ ้สำหรับขั้วไฟฟ้าประเภทนี้ แล<mark>ะสา</mark>มา<mark>รถแก้ไขได้ด้วยการนำโว</mark>ลต์มิเ<mark>ตอร์</mark>ที่มีค่าอิมพิแดนซ์สูง ๆ มาต่อ ระหว่างขั้วไฟฟ้าอ้างอิงและขั้วไฟฟ้าใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้กระแสไหลย้อนมาทางขั้วไฟฟ้าอ้างอิง แต่ ้ข้อควรระวัง คือ ขั้วเปรียบเที<mark>ยบที่ใช้ต้องเป็นชนิดเดียวกับอิเล็กโทรดในขั้ว</mark>แก้ว นอกจากนี้ความเข้มข้น ของสารละลาย KCl ในอิเล็กโท<mark>รดอ้างอิงต้องเท่ากับในขั้วแก้วด้วยโดยก</mark>ารใช้เทคนิคนี้ กระแสที่เกิดขึ้น ้จะไหลระหว่างขั้วไฟฟ้าใช้งานกับขั้วไฟฟ้าร่<mark>วมและถูกวัดออกมาด้วย</mark>แอมป์มิเตอร์ สำหรับความต่างศักย์ ้จะถูกวัดระหว่างขั้วไฟฟ้าใช้งานกับขั้วไฟฟ้าอ้างอิงโดยอาศัยโวลต์มิเตอร์ โดยแอมป์มิเตอร์จะต้องมี ความสามารถในการอ่านค่าได้ละเอียดถึงระดับไมโครแอมป์เป็นอย่างน้อย ในขณะที่โวลต์มิเตอร์จะต้อง กันกระแสที่เกิดขึ้นจากการทดลองไม่ให้เข้ามารบกวนการวัดค่าความต่างศักย์ตลอดการทดลอง ้โดยทั่วไปแล้วจะนิยมใช้โพเทนทิโอมิเตอร์ (Potentiometer) เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามเครื่องมือวัดแบบดิจิตอลสมัยใหม่ (Modern digital meter) ก็มีความสามารถในการ วัดที่ให้ค่าความถูกต้องได้ใกล้เคียงกับโพเทนทิโอมิเตอร์

4) สารละลายนำไฟฟ้า (Electrolyte) ทำหน้าที่เป็นสะพานเกลือ (Salt bridge) ให้กับระบบไฟฟ้าเคมี โดยทั่วไปแล้วการเลือกใช้สารละลายนั้นไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่น มากมาย เพียงแค่เป็นสารที่สอดคล้องกับการทดลองที่ต้องการเท่านั้นและที่สำคัญคือ สารละลายนั้น จะต้องแตกตัวเป็นไอออนบวกและไอออนลบเมื่ออยู่ในน้ำเพื่อทำให้เซลล์ไฟฟ้าเคมีเกิดเป็นวงจรปิด และ สามารถเกิดการนำไฟฟ้าได้

5) แหล่งกำเนิดศักย์ไฟฟ้า (Source of potential) เป็นแหล่งพลังงาน ที่ทำให้ขั้วไฟฟ้าใช้งานเกิดปฏิกิริยา โดยทั่วไปสำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่ทดลองเกี่ยวกับการกัดกร่อน มักจะใช้โพเทนทิโอสแทต (Potentiostats) ที่มีขายทั่วไปเป็นแหล่งพลังงาน ซึ่งโพเทนทิโอสแทตจะให้ ความต่างศักย์ที่มีค่าเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงไปยังขั้วไฟฟ้าใช้งานและจะทำให้เกิดการไหลของกระแส และ ในขณะเดียวกันก็จะทำให้เกิดความต่างศักย์ระหว่างขั้วไฟฟ้าใช้งานและขั้วไฟฟ้าอ้างอิง

#### 2.5 การวิเคราะห์ซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส

การหาค่าซีโอดีจากกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะคะไลซิส ที่มีการต่อเซลล์ไฟฟ้า 3 ขั้วเข้ากับ เครื่องจ่ายความต่างศักย์ไฟฟ้า เมื่อทำการฉายแสงไปยังตัวเร่งปฏิกิริยา จะได้ออกมาเป็น photocurrent: I<sub>ph</sub> (Li, Zhang, Li, and Zhao, 2012; Z. Zhang et al., 2007; Zhao, Jiang, Zhang, and Catterall, 2004) การออกซิไดซ์สาร<mark>อิน</mark>ทรีย์สามารถแสดงได้ดังสมการที่ (2.29)

 $C_{y}H_{m}O_{j}N_{k}X_{q} + (2y - j)H_{2}O \rightarrow yCO_{2} + qX^{-} + kNH_{3} + (4y - 2j + m - 3k)H^{+} + (4y - 2j + m - 3k - q)e^{-}(2.29)$ 

เมื่อ N คือ ในโตรเจนอะตอม X คือ ฮาโลเจนอะตอม y, m, j, k, q คือจำนวนอะตอมของ คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ในโตรเจน แ<mark>ละ</mark>ฮาโลเจนในสารประกอบอินทรีย์ตามลำดับ

และในการหาค่าซีโอดีจะอาศ<mark>ัยกฏ</mark>การแยกสารด้วยไฟ<mark>ฟ้า</mark>ของฟาราเดย์ (Faraday' law) มาใช้ หาความเข้มข้นเมื่อสารอินทรีย์ถูกออกซิไดซ์ สมการเป็นดังนี้

$$Q = \int I_{ph} dt = nFVC$$

โดยที่ Q คือปริมาณประจุไฟฟ้า I<sub>ph</sub> คือกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการออกซิไดซ์สารประกอบ อินทรีย์ t คือเวลา n คือจำนวนอิเล็กตรอนที่เปลี่ยนแปลง สามารถหาค่าได้จาก 4y - 2j + m - 3k – q ในสมการที่ (2.29) F คือค่าคงที่ของฟาราเดย์ (96,485 คูลอมบ์, c หรือ 6.022X10<sup>23</sup> อิเล็กตรอน, e<sup>-</sup>) V

(2.30)

้ เกิดมาการที่ (2.29) 1 คอคาคงที่เอง (11 แต่อ (90,485) คู่เกียม 0, 0 ที่ 10 0.022×10 คือ ปริมาตรน้ำตัวอย่าง และ C คือความเข้มข้นของสารอินทรีย์

หลักการของการหาค่าซีโอดีจากกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสคือ เมื่อทำการจ่าย ความต่างศักย์ไฟฟ้าและทำการฉายแสงไปยังตัวเร่งปฏิกิริยา แล้ววัดกระแสไฟฟ้าช่วงระยะเวลาหนึ่ง จะพบว่า Iph(blank) จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นจนเข้าสู่สภาวะสมดุล หรือเสถียร และ Iph(total) จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นเมื่อเกิดการออกซิไดซ์สารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำ และจะค่อย ๆ ลดลงจนถึงระดับเดียวกันกับ Iph(blank) เมื่อสารอินทรีย์ถูกออกซิไดซ์จนหมด โดยที่ Iph(blank) คือค่ากระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการ ออกซิเดชันของน้ำที่ไม่มีสารอินทรีย์ Iph(total) คือค่ากระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการออกซิเดชันของน้ำที่มี สารอินทรีย์ ปริมาณประจุไฟฟ้าของน้ำที่ไม่มีสารอินทรีย์ (Q<sub>blank</sub>) และปริมาณประจุไฟฟ้าของน้ำที่มี สารอินทรีย์ (Q<sub>total</sub>) จะได้จากการอินทริเกรต ของ Iph(blank)และ Iph(total) จากสมการที่ (2.30) และการ ออกซิไดซ์สารอินทรีย์อย่างสมบูรณ์ (Q<sub>net</sub>) หาได้จากการแทนค่าแสดงดังสมการที่ (2.31)

$$Q_{net} = \int I_{ph(total)} dt - \int I_{ph(blank)} dt = Q_{total} - Q_{blank}$$
(2.31)

สมการการแตกตัวของออกซิเจน สมการที่ (2.32) จะได้ว่า O<sub>2</sub> 1 โมลให้ 4 อิเล็กตรอน ซึ่งเมื่อ แทนค่าในสมการที่ (2.30) จะได้ค่าความเข้มข้นออกซิเจน ซึ่งเทียบเท่ากับได้ค่าซีโอดี ดังสมการที่ (2.33)

$$O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O \tag{2.32}$$

$$COD(mg O_2 L^{-1}) = \frac{Q_{net}}{4FV} \times 32000 = \frac{nC}{4} \times 32000$$
(2.33)

#### 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

#### 2.6.1 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา<mark>ด้วยกระ</mark>บวนการแอโนไดซ์

้จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า มีนักวิจัยหลายกลุ่มได้มีการพัฒนาเกี่ยวกับซิงค์ออก ไซด์ เช่น Basu, Saha et al. (2008) ได้ทำการศึกษาผลกระทบของแสงยูวีต่อซิงค์ออกไซด์ฟิล์ม ้สังเคราะห์ขึ้นจากกระบวนการแอโนไดเซชั<mark>น โด</mark>ยใช้แผ่น<mark>ซิง</mark>ค์บริสุทธิ์ (Zn) 99.9% หนา 0.5 มิลลิเมตร เป็น working electrode ใช้แพลทินัม (Pt) เป็น counter electrode และใช้ calomel เป็น reference electrode มีการควบคุมให้ความต่างศักย์ไฟฟ้า<mark>คง</mark>ที่ 10 โวลต์ และใช้ความเข้มข้นของ oxalic acid ซึ่งเป็นสารอิเล็กโทรไล<mark>ต์ที่ค</mark>วามเข้มข้นต่างกัน คื<mark>อ 0.</mark>3 0.5 และ 1 โมลาร์ ทั้งในสภาวะที่ ฉายแสงและไม่ฉายแสง พบว่าควา<mark>ม</mark>เข้มข้นของสารอิเล็กโทรไลต์ส<mark>ูง</mark>และการฉายแสงมีผลทำให้ขนาด ของผลึกและเส้นผ่านศูนย์กลา<mark>งข</mark>องร**ูพรุนมีขนาดให**ญ่ขึ้น และในปีเดียวกันนั้น Kim, Lee et al. ได้ ทำการศึกษากระบวนการแ<mark>อโน</mark>ได<mark>เซชันของซิ</mark>งค์ในสารอิเล็กโท<mark>รไล</mark>ต์ที่มีฟลูออไรด์ไอออนเป็น ้องค์ประกอบ พบว่าเมื่อทำการจ่ายศักย์ไฟฟ้าที่ต่ำ ๆ และศักย์ไฟ<mark>ฟ้าที่สูง</mark> ๆ ลักษณะสัณฐานของซิงค์อ อกไซด์ที่ใช้สารอิเล็กโทรไลต์ชน<mark>ิดกรดไฮโดรฟลูออริก (Hydrofluoric ac</mark>id, HF) จะมีโครงสร้างแตกต่าง กัน โดยที่ศักย์ไฟฟ้าที่ต่ำ ๆ เป็นแบบ Etching structure และศักย์ไฟฟ้าที่สูง ๆ เป็นแบบ Nanowires แต่สารอิเล็กโทรไลต์ชนิดโซเดียมฟลูออไรด์กลับมีโครงสร้างเป็นแบบ Nanowires เหมือนกัน He, Zheng et al. (2010) ได้ทำการเตรียมและศึกษาคุณสมบัติของนาโนซิงค์ออกไซด์จากกระบวนการ แอโนไดเซชัน โดยใช้แผ่นซิงค์บริสุทธิ์ (Zn) 99.99% หนา 0.25 มิลลิเมตร เป็น working electrode ใช้แผ่นกราไฟต์ (graphite plate) เป็น counter electrode ใช้น้ำ กรดไฮโดรฟลูออริก และเมทานอล เป็นสารอิเล็กโทรไลต์ ทำการจ่ายแรงดันคงที่ที่ 9.7 โวลต์ พบว่าที่ระยะเวลาต่างกัน ลักษณะโครงสร้าง และขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของรูพรุนมีขนาดแตกต่างกัน Zhao, Wang et al. (2011) ้ทำการศึกษาการควบคุมลักษณะโครงสร้างของซิงค์ออกไซด์ ขนาด 20 × 20 × 0.1 ตารางมิลลิเมตร ที่ ้ผ่านการแอโนไดเซชันที่ระยะเวลาต่างกัน ในสารละลายแอมโมเนียมซัลเฟต 0.2 โมลาร์ ผสมกับ ้แอมโมเนียมคลอไรด์ 0.2 โมลาร์ จ่ายความต่างศักย์ไฟฟ้า 1 โวลต์ เมื่อนำไปส่องกล้องจุลทรรศน์ ้อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) พบว่าลักษณะโครงสร้างและขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของรูพรุนมี ขนาดแตกต่างกันเช่นกัน Farrukh, Thong et al. (2012) ยังได้ทำการศึกษาการย่อยสลายเมทิลีนบลู โดยใช้ซิงค์ออกไซด์ที่ผ่านการแอโนไดเซชันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา พบว่าการจ่ายความต่างศักย์ไฟฟ้าสูง

ประสิทธิภาพการย่อยสลายจะเกิดขึ้นได้ดีกว่าที่ความต่างศักย์ต่ำ นอกจากนี้ Shetty and Nanda (2012) ก็ได้ทำการสังเคราะห์ซิงค์ออกไซด์เพื่อให้โครงสร้างมีรูพรุนโดยใช้น้ำเป็นสารอิเล็กโทรไลต์ พบว่าการจ่ายความต่างศักย์ในช่วงแรกจะทำให้เกิดการก่อตัวของออกไซด์บนพื้นผิวซิงค์ จนเมื่อ ระยะเวลาผ่านไปก็จะเกิดเป็นซิงค์ออกไซด์ และเมื่อใช้ระยะเวลาในการทำแอโนไดซ์นานขึ้นลักษณะของ โครงสร้างรูพรุนจะมีขนาดใหญ่ขึ้น แต่ความหนาลดลง

#### 2.6.2 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยกระบวนการแอโนไดซ์แบบพัลส์

้ ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงโครงสร้างและลักษณะทางสัณฐานวิทยาของไทเทเนียมไดออกไซด์ รูปท่อด้วยวิธีการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ซึ่งการพัลส์เป็นวิธีการหนึ่งที่ได้นำมาใช้กัน (Han, Choi, Zhao, Baik, & Lee, 2007) ซึ่งได้มีศึกษาผลของสารละลายอิเล็กโทรไลท์และการจ่ายศักย์ไฟฟ้า แบบพัลส์ด้วยวิธีการแอโนไดซ์ ในด้านสารละลายอิเล็กโทรไลท์ได้ใช้เป็นแอมโมเนียมฟลออไรด์ (Ammonium floride : *NH₄F*) และกลีเซอรอล (G<mark>ly</mark>cerol) พบว่าลักษณะสัณฐานวิทยาของไทเทเนียม ้ไดออกไซด์รูปท่อที่ใช้สารละลายอิเล็กโทรไลท์ที่มี<mark>ส่ว</mark>นผสมของแอมโมเนียมฟลูออไรด์ในกลีเซอรอลมี รูปร่างและขนาดรูพรุนเล็กกว่าสารละลายอิเล็กโทรไลท์ที่ใช้แอมโมเนียมฟลูออไรด์เพียงอย่างเดียว และ ในด้านการใช้ศักย์ไฟฟ้าแบบพัลส์นั้นพบว่าขนาดของรูพรุนเล็กลง ความหนาแน่นกระแสที่ถูกกระตุ้น ้จากแสงยังมีค่าเพิ่มขึ้นอีกด้วย (Chanmanee et al., 2<mark>0</mark>07) ในด้านการย่อยสลายสีเมทิลีนบูลและการ ้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์<mark>รูปท่</mark>อที่เตรีย<mark>มโด</mark>ยการแอโนไดซ์แบบพัลส์ โดยระหว่างการ ้แอโนไดซ์จะแบ่งการทดลองให้มีการกวนส<mark>าร</mark>ละลายอิเล็<mark>กโท</mark>รไลท์และไม่กวนร่วมด้วย ซึ่งพบว่าเมื่อมี การกวนในระหว่างแอโนไดซ์นั้น ความ<mark>ยาว</mark>ของท่อจะเพิ่มขึ้น เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อมีขนาดเล็กลง ้แต่จะให้รูปร่างลักษณะของท่อที่ไม่เป็นระเบียบ ส่วนในด้านก<mark>ารย่</mark>อยสลายของสีเมทิลีนบูลนั้น พบว่า ้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีการกวนนั้นให้ประสิทธิภาพดีที่สุด ซึ่งหมายความว่ารูปร่างที่ไม่เป็นระเบียบนั้นไม่ ้ส่งผลต่อการย่อยสลายของสี แ<mark>ต่ในด้านการฆ่าเชื้อโรคด้วยไท</mark>เทเนี<mark>ยมไ</mark>ดออกไซด์นั้นจะแบ่งปฏิกิริยา ้ออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นต<mark>อนแ</mark>รกจ<mark>ะเป็นการทำลายเยื้อหุ้มภา</mark>ยนอ<mark>กขอ</mark>งเซลล์แบคทีเรีย ในขั้นตอนนี้ ู้ปฏิกิริยาจะเกิดอย่างช้า ๆ แ<mark>ละเมื่อเย</mark>ื้อหุ้มภายนอกเซลล์ถูกทำล<mark>ายแล้ว</mark>จะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 คือการ ทำลายเซลล์นั้น ๆ ซึ่งปฏิกิริย<mark>าที่เกิดในขั้นตอนนี้จะเกิดอย่างรวด</mark>เร็ว (Sunada, Watanabe, & Hashimoto, 2003) ซึ่งตรงกับผลการทดลองที่พบว่าตัวเร่งปฏิกิริยาที่สังเคราะห์ได้นั้นจะใช้เวลาใน ้ขั้นตอนแรก 2 - 3 ชั่วโมง และ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมงในขั้นตอนที่สอง และยังให้ประสิทธิภาพ ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียมากถึง 95% (Chang, Lee, Chen, Liu, & Weng, 2011) ไทเทเนียมไดออกไซด์ รูปท่อที่เตรียมโดยการแอโนไดซ์แบบพัลส์นั้น นอกจากขนาดของรูพรุนที่เล็กกว่าวิธีการแอโนไดซ์แบบ ธรรมดาแล้ว ยังทำให้ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้เกิดเป็นโครงสร้างลักษณะไม้ไผ่ (Bambootype) ซึ่งข้อดีโครงสร้างลักษณะไม้ไผ่ คือ ทำให้มีพื้นที่ผิวเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับลักษณะท่อที่เกิดขึ้น แบบปกติ (Roy, Berger, & Schmuki, 2011) และยังปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพการตอบสนองต่อแสง ที่มากขึ้นอีกด้วย (Xie et al., 2012)

#### 2.6.3 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยกระบวนการสปัตเตอริง

้จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า นักวิจัยได้ทำการศึกษาและพัฒนาการสังเคราะห์ ้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดต่าง ๆ ด้วยกระบวนการสปัตเตอริง โดยได้ทำการศึกษาในประเด็นที่แตกต่างกัน ออกไป ดังนี้ Deng, Huang et al. (2010) ได้ทำการศึกษาผลของคุณสมบัติของฟิล์ม ZnO ที่มีการเจือ ้ด้วย Al ที่อัตราส่วนต่างกัน บนควอตซ์ โดยใช้วิธี RF magnetron sputtering สปัตเตอริงร่วมกัน ระหว่างเป้าของ Al<sub>2</sub>O3 ที่มีการแปรผันกำลังไฟฟ้าที่ใช้ในการสปัตเตอริงที่ 50 ถึง 100 วัตต์ และ ZnO ใช้กำลังไฟฟ้าคงที่ 100 วัตต์เท่ากัน ทุก ๆ อัตราส่วนใช้เวลาในการสปัตเตอร์ 30 นาที พบว่า เมื่อเพิ่ม ้ กำลังไฟฟ้าจะมีสัดส่วนของ Al เพิ่มขึ้นจาก 1.80 ถึง 8.06% โดยมีสัดส่วนการเพิ่มขึ้นเกือบเป็นเส้นตรง และจากภาพถ่าย FESEM พบว่า ZnO ที่ไม่มีการเจือด้วย Al จะมีลักษณะสัณฐานวิทยาเป็น รูปทรงพีระมิด (pyramidal shape) ขนาด 120 – 180 นาโนเมตร หนา 200 ± 20 นาโนเมตร แต่เมื่อ ้มีการเจือ Al ลงไปจะพบรูปทรงกระสวย (fusifo<mark>rm</mark> shape) ขนาดเล็กที่บริเวณพื้นผิวด้านบนแทน ้ความหนาเพิ่มขึ้นเป็น 300 ± 20 นาโนเมตร และ<mark>จา</mark>กการวิเคราะห์ด้วย AFM พบว่า ความหยาบของ ้ พื้นผิวฟิล์มจะลดลงเมื่อมีการเจือด้วย Al และกา<mark>รส่งผ่าน</mark>แสงสูงมากกว่า 80% ตลอดช่วงความยาวคลื่น 400 – 1,500 นาโนเมตร สภาพการเคลื่อนที่ได้ (mobility) ของพาหะ (อิเล็กตรอนและโฮล) และ ้ความหนาแน่นของพาหะนำไฟฟ้า (carrier concentration) สูงที่สุดเมื่อเจือ Al ลงบน ZnO 4.5% Han, Wang et al. (2011) ได้ทำการเคลือบ ZnO บนกระจกด้วยวิธี RF magnetron sputtering เติม Ar ที่ความดัน 2 มิลลิทอร์ (mTorr) และศึกษาผลของการใช้กำลังไฟฟ้าในการสปัตเตอร์ที่ต่างกันคือ 90 100 110 120 130 และ 140 วัตต์ จา<mark>กกา</mark>รศึกษาผลของกำลั<mark>งไฟ</mark>ฟ้าต่อความเป็นผลึก ลักษณะสัณฐาน ้ วิทยา และความขรุขระของฟิล์มบาง <mark>พบว</mark>่า พีคของความเป็นผ<mark>ลึกข</mark>อง ZnO สูงขึ้น ผลึกมีขนาดใหญ่ขึ้น ้ และชัดเจนขึ้น อีกทั้งยังพื้นผิวยังมี<mark>คว</mark>ามหยาบมากขึ้นเมื่อเพิ่มกำลัง<mark>ไ</mark>ฟฟ้าในการสปัตเตอริง นอกจากนี้ ้ยังได้ทำการทดสอบคุณสมบัติ<mark>ทางไฟฟ้าของวัสดุที่อุณหภูมิห้อง</mark>ด้วย <mark>ซึ่งพ</mark>บว่ากำลังไฟฟ้าที่เหมาะสมใน การสปัตเตอริงคือ 100 วัตต์ เนื่องจากมีสภาพการเคลื่อนที่ได้ของพาหะอยู่ที่ 34 ตารางเซนติเมตรต่อ โวลต์ต่อวินาที (cm²/V·s) ซึ่งมีค่าสูงกว่าที่สปัตเตอริงด้วยกำลังไฟฟ้าอื่น ๆ จากนั้นในปี 2013 Prepelita, Craciun et al. ได้ใช้วิธี RF magnetron sputtering เช่นกัน ในการเคลือบ ZnO ลงบน พอลิเอไมด์ฟิล์ม (polyamide film<mark>) หรือเคปตอนฟิล์ม ใช้ก้าซ</mark>อาร์กอนเป็นก้าซเฉื่อย และกำลังไฟฟ้า 120 วัตต์ ในการสปัตเตอริงให้ได้ความหนาของฟิล์ม 70 และ 150 นาโนเมตร หลังจากนั้นศึกษาผลของ อุณหภูมิที่ใช้ในการอบหลังจากที่ทำการสปัตเตอริงที่ 250 และ 350 องศาเซลเซส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ซึ่งพบว่าฟิล์มที่ความหนาทั้ง 2 ชุด เมื่อผ่านการนำไปอบจะทำให้มีความขรุขระของฟิล์มมากขึ้นและเมื่อ ้นำไปอบที่อุณหภูมิสูงกว่าความขรุขระก็จะสูงกว่า และความหนาของฟิล์มที่ 150 นาโนเมตร เมื่อ ้ วิเคราะห์ด้วย XRD จะพบพีคของ ZnO ที่มีความเข้มสูงกว่าที่ 70 นาโนเมตร และการส่องผ่านของแสง เพิ่มขึ้นจาก 70% เป็น 85% ในช่วง 400 – 600 นาโนเมตร หลังจากที่ทำการอบ อีกทั้งยังพบว่าทำให้ แถบช่องว่างพลังงานของฟิล์มที่มีความหนา 70 นาโนเมตร เพิ่มขึ้นจาก 3.19 eV เป็น 3.22 eV และ ของฟิล์มที่มีความหนา 150 นาโนเมตร เพิ่มขึ้นจาก 3.20 eV เป็น 3.24 eV ซึ่งคุณภาพของฟิล์มที่ได้นี้ ้สามารถนำไปใช้ในงานโซลาร์เซลล์ได้ และในปีเดียวกันนั้น Khazamipour, Kabiri-Ameri-Aboutorabi et al. ก็ได้ใช้วิธี RF sputtering เคลือบ ZnO ลงบนพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (polyethylene terephthalate, PET) โดยดูผลของการเคลือบ Al<sub>2</sub>O3 และ SiO2 ลงบน PET ก่อนที่จะสปัตเตอร์ ZnO ้ลงไป ต่อคุณสมบัติทางไฟฟ้าและแสง ซึ่งพบว่า การสปัตเตอร์ ZnO ลงบน PET เลย (ZnO/PET) การ

้ส่องผ่านของแสงเฉลี่ยอยู่ที่ 80% ในช่วง 200 – 800 นาโนเมตร และลดลงเป็น 69% เมื่อเคลือบ Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ้ลงบน PET ก่อนที่จะสปัตเตอร์ ZnO ลงไป (ZnO/ Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/PET) และเพิ่มขึ้นเป็น 81% เมื่อเคลือบ เคลือบ SiO<sub>2</sub> และ Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ลงบน PET ตามลำดับ ก่อนที่จะสปัตเตอร์ ZnO ลงไป (ZnO/ Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/ SiO<sub>2</sub> /PET) ซึ่งทำให้มีแถบช่องว่างพลังงานเป็น 3.25 2.75 และ 3.3 eV ตามลำดับ จากนั้น Purohit, Chander et al. (2015) ได้ทำการสปัตเตอริง ZnO บน ITO glass ด้วยวิธี RF sputtering โดยทำงาน ้ศึกษาผลของการอบฟิล์มที่อุณหภูมิต่ำ ๆ ช่วง 150 – 450 องศาเซลเซียส พบว่า ความหนาแน่นของผลึกต่อ ้พื้นที่ลดลงแต่ขนาดของเกรนใหญ่ขึ้นและมี texture coefficient มากขึ้นซึ่งมีการจัดเรียงตัวในแนว ระนาบที่มีความจำเพาะเจาะจง แต่การดูดกลืนของแสงบนฟิล์มต่ำลงเมื่ออบที่อุณหภูมิสูงขึ้น และมี ้ความสามารถดูดกลืนแสงในช่วงวิสิเบิลได้น้อยแต่ดูดกลืนแสงในช่วงยูวีได้สูง อีกทั้งยังมีแถบช่องว่าง พลังงานอยู่ในช่วง 3.30 - 3.52 eV โดยที่แถบช่องว่างพลังงานลดลงเมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการอบ ยกเว้น ู้ ที่ 150 องศาเซลเซียสที่มีการเพิ่มเนื่องจากมีจำนว<mark>นผ</mark>ลึกของ ZnO ต่อพื้นที่สูงกว่าฟิล์มอื่น Sreedhar, Kwon et al. (2016) ทำการสปัตเตอริงโดยเจือ Cu ด้วยวิธี DC magnetron sputtering ลงไปยังฟิล์ม ZnO ที่สปัตเตอริงด้วยวิธี RF magnetron sputtering บนกระจกเป็นเวลา 40 นาที ใช้กำลังไฟฟ้า ้สำหรับสปัตเตอร์ ZnO 150 วัตต์ และกำลังไฟฟ้าสำหรับสปัตเตอร์ Cu 0 4 6 และ 8 วัตต์ เพื่อให้มี Cu ้ในปริมาณที่แตกต่างกัน พบว่าฟิล์มมีความหน<mark>า</mark>เพิ่มขึ้<mark>น</mark>เมื่อเพิ่มกำลังไฟฟ้าสำหรับสปัตเตอร์ Cu ซึ่ง ้ปริมาณของ Cu ที่เพิ่มขึ้นทำให้ความต้านทา<mark>นไฟ</mark>ฟ้าเพิ่มขึ้<mark>นก</mark>ารส่องผ่านของแสงลดลง และแถบช่องว่าง พลังงานลดลง Jayaraman, Kuwabara et al. (2016) ได้ศึกษาผลของความเร็วรอบการหมุนของแท่น รองรับเมื่อทำการสปัตเตอริงต่อการก่อ<mark>ตัวข</mark>องฟิล์ม ZnO โดย<mark>ทดล</mark>องที่ความเร็ววรอบ 0 20 40 60 และ 80 รอบต่อนาที (rpm) พบว่า ฟิล์มมีค่าการส่องผ่านแสงมากกว่า 90% ความเร็วที่ 40 rpm ทำให้ผลึก ของ ZnO มีขนาดใหญ่กว่าความเร็วรอบอื่น ๆ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างการไม่หมุนแท่นรองรับและ การหมุนที่แท่นรองรับที่ความเร็วรอบต่าง ๆ พบว่า การไม่หมุนแท่นรองรับขนาดผลึกจะแตกต่างกันซึ่ง ้อยู่ในช่วง 50 – 200 นาโมเมตร และบางพื้นที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม การหมุนแท่นรองรับที่ความเร็ว รอบ 20 rpm จะทำให้ลักษณ<mark>ะพื้นผิว</mark>ของฟิล์มแต่ละจุดมีความคล้ายคลึงกัน ขนาดของผลึกใกล้เคียงกัน แต่ก็มีบางจุดที่ขนาดผลึกใหญ่กว่าจุ<mark>ดอื่น ๆ เมื่อเพิ่มความเร็วรอบเป็น 4</mark>0 rpm ขนาดผลึกมีการกระจาย ้ตัวอย่างสม่ำเสมอและมีขนาดใกล้เคียงกั<mark>น แต่เมื่อเพิ่มความเร็วร</mark>อบเป็น 60 และ 80 rpm บนฟิล์มเริ่ม มีการรวมกลุ่มกันของ ZnO ขนาด 50 – 100 นาโนเมตร อีก Nandi and Major (2017) ทำการสปัต เตอริง ZnO ด้วยวิธี DC sputtering โดยศึกษาการก่อตัวของ ZnO บน Si เมื่อแปรเปลี่ยนปัจจัยต่าง ๆ ้ดังนี้จากการศึกษาผลของอุณหภูมิที่ฐานรองรับ พบว่า จากการวิเคราะห์ด้วย XRD พีคของ ZnO ลดลง แต่ชัดเจนขึ้นเมื่อเพิ่มอุณหภูมิที่ฐานรองรับซึ่งสอดคล้องกันกับผลของรามาน (raman spectra) และ จากภาพถ่าย FESEM ในภาพตัดขวางจะเห็น ZnO ที่มีลักษณะเป็นแท่งรูปร่างชัดเจนมีการกระจาย ้ตัวอย่างสม่ำเสมอ ผลของกำลังไฟฟ้า พบว่าลักษณะรูปทรงมีความคล้ายคลึงกันมีการกระจายตัวอย่าง ้สม่ำเสมอ แต่ขนาดและความหนาของฟิล์มเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มกำลังไฟฟ้า ผลของความดันก๊าซอาร์กอน พบว่าลักษณะรูปทรงมีความคล้ายคลึงกันมีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ แต่ขนาดไม่แตกต่างกันแต่ ้ความหนาของฟิล์มลดลงเมื่อเพิ่มความดันก๊าซอาร์กอน และผลของปริมาณก๊าซออกซิเจน พบว่า ้ลักษณะรูปทรงมีความคล้ายคลึงกัน มีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ ขนาดและความหนาของฟิล์มแทบ ้ไม่แตกต่างกันเมื่อเพิ่มปริมาณก๊าซออกซิเจน ซึ่งจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิที่ฐานรองรับเป็นปัจจัยที่สำคัญ ที่สุดที่จะทำให้คุณลักษณะสัณฐานวิทยาของฟิล์มเปลี่ยนแปลงไป

#### 2.6.4 การวิเคราะห์ซีโอดีโดยกระบวนการต่าง ๆ

้จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์หาค่าซีโอดี โดยกระบวนการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่วิธีมาตรฐานไดโครเมต พบว่า มีการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส โดยใช้การ ใหลแบบต่อเนื่อง (flow injection) ในการหาค่าซีโอดี ซึ่งใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) เป็นชนิด เม็ดลูกปัดบรรจุไว้ในคอลัมน์ ซึ่งผลการทดลองพบว่า สามารถหาค่าซีโอดีได้ในช่วง 0.12 – 8 ppm และ ใช้เวลาในการวิเคราะห์ประมาณ 10 นาที (Kim et al., 2001) และในปี 2004 Zhao, Jiang et al. ประยุกต์ใช้ฟิล์ม TiO2 แบบ nanoporous เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ซึ่งเคลือบบน Indium tin oxide แล้ว ้นำมาใช้ในการวิเคราะห์หาค่าซีโอดีได้ในช่วง 0 – 200 มิลลิกรัมต่อลิตร ใช้ระยะเวลาเพียง 5 – 10 นาที ้เท่านั้น ต่อมาได้มีการพัฒนาขึ้นโดยเปลี่ยนมาใช้ TiO<sub>2</sub> ชนิดเคลือบแผ่นฟิล์มบาง ที่สังเคราะห์ขึ้นด้วย กระบวนการโซล-เจล (sol-gel dip coating method) และในชุดการทดลองได้เพิ่มส่วนที่เป็น เซลล์ไฟฟ้าแบบ 3 ขั้ว เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาค<mark>่าซ</mark>ีโอดี โดยการแปลงผลจากปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น กล่าวคือ ปฏิกิริยาเคมีดังกล่าวจะให้พลังงานไฟฟ้<mark>าออ</mark>กมา ซึ่งสามารถวัดค่าออกมาในรูปของการไหล ของกระแส (photocurrent: I<sub>oboto</sub>) และนำมาแ<mark>ทนค่าใ</mark>นสมการเพื่อให้ได้ค่าซีโอดี ผลการทดลองของ ้งานวิจัยนี้พบว่า สามารถหาค่าซีโอดี ได้ในช่วง 0.5 - 235 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีสัมประสิทธิ์ ้สหสัมพันธ์ (R<sup>2</sup>) เท่ากับ 0.9998 (Chen et al.<mark>,</mark> 2005) <mark>ต่</mark>อมาได้มีการพัฒนาสารกึ่งตัวนำอย่างต่อเนื่อง โดย Zhang, Yuan et al. 2007 ทำการปรับปรุงให้มีส<mark>าร</mark>กึ่งตัวนำสองชนิดผสมกันคือ ZnO/ TiO<sub>2</sub> ิเตรียมโดยวิธี vacuum vaporized และ s<mark>ol-</mark>gel ใช้ในก<mark>ารวิ</mark>เคราะห์หาค่าซีโอดีโดยกระบวนการโฟโต คะตะไลติก พบว่า สามารถหาค่าซีโอดี<mark>ที่คว</mark>ามเข้มข้นต่ำ ๆ 0.<mark>3 –</mark> 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งประสิทธิภาพ ของกระบวนการที่เกิดขึ้นจะสูงกว่าก<mark>ารใช้</mark> ZnO หรือ TiO<sub>2</sub> เพี<mark>ยงอย่</mark>างเดียว นอกจากกระบวนการโฟโต ้คะตะไลซิสที่สามารถประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์หาค่าซีโอดีแล้ว วิธีการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสก็ยังมี การศึกษาเพื่อใช้วิเคราะห์หาค่าซีโอดีเช่นกัน โดย Zhang et al. (2009) ได้ทำการศึกษากระบวนการโฟ โตอิเล็กโตรคะตะไลซิสในการหาค่าซีโอดี โดยใช้ TiO2 ชนิดท่อนาโนที่เรียงเป็นแถว ในงานวิจัยได้ทำ การสังเคราะห์ TiO<sub>2</sub> โดยใช้ก<mark>ระบวน</mark>การแอโนไดเซชัน (Anodization) โดยใช้พารามิเตอร์ที่ต่างกัน 2 แบบ โดยพารามิเตอร์ที่ให้ไทเ<mark>ทเนียมไดออกไซด์ที่ดีที่สุด คือ ใช้ 1%</mark> HF เป็นสารละลายนำไฟฟ้า (electrolyte) ความต่างศักย์ 20 โ<mark>วลต์ เวลา 5 นาที และอุณหภู</mark>มิในการอบ450 ℃ ใช้เวลา 3 ชม. สามารถวิเคราะห์หาค่าซีโอดีได้ในช่วง 0-850 มิลลิกรัมต่อลิตร และเมื่อใช้ TiO2 แบบฟิล์มบาง โดยใช้ แหล่งกำเนิดแสงเป็นหลอด UV-LED สามารถหาค่าซีโอดีได้ในช่วง 0-300 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งให้ผลการ ทดลองที่สอดคล้องกับวิธีมาตรฐานไดโครเมต มีความถูกต้องสูง ตัวเร่งปฏิกิริยามีความเสถียร สามารถ ้ทำซ้ำได้ และสามารถหาค่าซีโอดีได้ในน้ำเสียหลายประเภท รวมถึงสามารถแก้ปัญหาของน้ำที่มีการเจือ ปนของคลอไรด์และแอมโมเนียได้ จากนั้น Mu et al., 2011 ใช้ TiO2 ชนิด nanofiber เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา จากการเตรียมโดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล (Hydrothermal) ซึ่งสามารถวิเคราะห์หาค่า ซีโอดีได้ในช่วง 0-250 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เพียงเท่านั้น การพัฒนาของวัสดุในการวิเคราะห์หาค่าซีโอดี ้ยังมีเรื่อยมา โดย Wang, Wu et al. (2013) ได้ทำการวิเคราะห์ซีโอดีโดยใช้ Cu<sub>2</sub>O/TiO<sub>2</sub> เป็นตัวเร่ง ปฏิกิริยาในกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซีส ทำการจ่ายความต่างศักย์ที่ 0.3 V โดยมี Aq/AqCl เป็นขั้วไฟฟ้าอ้างอิง และสามารถวัดซีโดอีได้อยู่ในช่วง 20-30 มิลลิกรัมต่อลิตร นอกจากนี้ยังพบว่า การ ้ใช้ Cu<sub>2</sub>O/TiO<sub>2</sub> เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาจะมีความสามารถในการตอบสนองต่อแสงช่วง visible ได้มากขึ้น ในปีเดียวกันนักวิจัยกลุ่มดังกล่าวก็ได้ทำการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา TiO<sub>2</sub> บน FTO ด้วยกระบวนการ ไฮโดรเทอร์มอล มาทำการวัดค่าซีโอดิโดยใช้กระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส ศึกษาปัจจัยซึ่งได้แก่ 1) ความต่างศักย์ พบว่า ที่ความต่างศึกย์ตั้งแต่ 0.5- 1โวลต์ จะมีสัญญาณรบกวนของกระแสจากการวัด ซีโอดีน้อยกว่าที่ศักย์ไฟฟ้าต่ำกว่า 0.5 โวลต์ จึงทำการเลือกจ่ายความต่างศักย์ที่ 0.5 โวลต์ในการวัด ค่าซีโอดี 2) ความเข้มแสงของแหล่งกำเนิดแสงมีผลต่อการวัดค่าซีโอดีเป็นอย่างมาก โดยที่ความเข้มสูง จะทำให้การวัดค่าซีโดอีมีความเสถียรมากขึ้น โดยความเข้มแสงที่เหมาะสมอยู่ที่ 10 มิลลิวัตต์ต่อตาราง เซนติเมตร และ 3) ผลของพีเอช พบว่าที่พีเอช 4-10 ไม่มีผลต่อการวัดค่าซีโอดีด้วยกระบวนการ โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส และจากการวัดซีโอดีจากน้ำเสียสังคราะห์ 5 ชนิด ได้แก่ น้ำตาลกลูโคส ไกลซีน โพแทสเซียมไฮโดรเจนพธาเลต น้ำตาลซูโคส และกรดแลคติก นอกจากนั้นยังนำไปใช้วัดซีโอดี จากแหล่งน้ำโรงงานอุตสาหกรรม และน้ำใต้ดิน 9 แหล่ง พบว่า วัดซีโอดีได้ในช่วง 20-280 มิลลิกรัมต่อ ลิตร จากนั้นในปี 2016 Zhang et al. ยังได้ทำการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา TiO<sub>2</sub> ด้วยวิธีแอโนไดเซ ชัน ที่ความต่างศักย์ 50 โวลต์ เป็นเวลา 15 นาที มาทำการวัดซีโอดีก้อยกระบวนการ โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสโดยใช้น้ำตัวอย่างที่สังเคราะห์ที่เตรียมจากสารให้ค่าซีโอดีก้วยกระบวนการ โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสโดยใช้น้ำตัวอย่างที่สังเคราะห์ที่เตรียมจากสารให้ค่าซีโอดีก้อด้ารบกระบวนการ โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสโดยใช้น้ำตัวอย่างที่สังเคราะห์ที่เตรียมจากสารให้ค่าซีโอดีก้างทฤษฎี 5 ชนิด ได้แก่ น้ำตาลกลูโคส โพแทสเซียมไฮโดดีเด้ในช่วง 20 – 250 มิลลิกรัมต่อลิตร



# บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

้ค่าซีโอดี (Chemical oxygen demand; COD) เป็นวิธีวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนทั้งหมดที่ ต้องการ เพื่อใช้ในการออกซิไดซ์ (Oxidize) สารอินทรีย์ในน้ำให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ ้ค่าซีโอดีเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญที่ใช้ในการประเมินคุณภาพน้ำเสีย รวมไปถึงใช้ในการออกแบบ ติดตาม ้ควบคุม และประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยเหตุที่การวิเคราะห์หาค่าซีโอดีนั้น ้สามารถที่จะทำการวิเคราะห์และได้รับผลการวิเคราะห์ในช่วงเวลาที่สั้น (3-5 ชั่วโมง) ซึ่งถ้าเทียบกับ การหาค่าบีโอดี (Biological oxygen demand; BOD) ที่ใช้เวลานานกว่า (5วัน) และมีวิธีการที่ยุ่งยาก ้กว่า ทำให้การวิเคราะห์หาค่าซีโอดีในน้ำเสียเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย และจากการวิเคราะห์หาค่า ซีโอดีตามวิธีมาตรฐาน เห็นได้ว่าในการวิเค<mark>รา</mark>ะห์จำเป็นต้องใช้สารเคมี หลายชนิด ได้แก่ โปแตสเซียมไดโครเมต (K2Cr2O7) ซิลเวอร์ซัลเฟ<mark>ต (</mark>Ag2SO4) กรดซัลฟิวริก (H2SO4) และเมอร์คิวริก ้ซัลเฟต (HeSO₄) โดยที่สารโปแตสเซียมไดโครเม<mark>ตและก</mark>รดซัลฟิวริก เป็นสารเคมีอันตราย กรดซัลฟิวริก ้เป็นกรดชนิดเข้มข้นมีความสามารถในการกัดกร่อนสูง และซิลเวอร์ซัลเฟตที่ใช้การวิเคราะห์ซีโอดีนี้เป็น สารเคมีที่มีราคาแพง และจากการศึกษาข้อมูล<mark>เ</mark>กี่ยวกับก<mark>ารวิ</mark>เคราะห์ซีโอดีด้วยวิธีการต่าง ๆ เห็นความ ้เป็นไปได้ที่จะศึกษาและพัฒนาวิธีการเหล่า<mark>นั้น</mark>เพื่อใช้วิเค<mark>ราะ</mark>ห์ค่าซีโอดีของน้ำเสีย โดยการศึกษาครั้งนี้ ้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ที่มุ่งเน้นศึกษาวิธีการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส ้โดยใช้วัสดุกึ่งตัวนำไทเทเนียมไดออ<mark>กไซ</mark>ด์และซิงค์ออกไซ<mark>ด์ (</mark>ZnO) ที่ผ่านการสังเคราะห์ด้วยวิธี แอโนไดเซชัน และซิงค์ออกไซด์ (ZnO) ที่ผ่านการสังเคราะห์ด้วยวิธีสปัตเตอริง จนมีคุณลักษณะที่ ้เหมาะสมในการนำมาใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส เพื่อวิเคราะห์หา ้ค่าซีโอดีในน้ำเสีย และสถานที่ทำการศึกษาในครั้งนี้ได้ทำการทดลอง ณ ห้องปฏิบัติการวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม บริเวณอาคารศูน<mark>ย์เครื่อ</mark>งมือ 4 5 และ 11 มหาวิทยาลั<mark>ยเทคโ</mark>นโลยีสุรนารี และสถาบันวิจัย ู แสงซินโครตรอน (องค์การมห<mark>าชน) จังหวัดนครราช</mark>สีมา ซึ่งมีขั้นต<mark>อนการ</mark>ศึกษาวิจัย ดังรูปที่ 3.1

> ะ <sup>3</sup>่าวักยาลัยเทคโนโลยีสุรุ่ม



รูปที่ 3.1 ขั้นตอนการศึกษาวิจัย

#### 3.1 ไทเทเนียมไดออกไซด์

#### 3.1.1 การสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์โดยวิธีการแอโนไดซ์แบบพัลส์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์แบบท่อนาโนสามารถทำได้โดย กระบวนการแอโนไดเซชัน ซึ่งเป็นเทคนิคที่ทำให้เกิดออกไซด์บนพื้นผิวหน้าของไทเทเนียมมีลักษณะ เป็นท่อนาโน (Nanotubes) กระจายตัวอยู่บนพื้นผิวของแผ่นไทเทเนียม เกิดจากการจ่ายกระแสไฟฟ้า เป็นจังหวะจากแหล่งกำเนิดไปสู่เซลล์เคมีไฟฟ้า (Electrodechemical cell) ซึ่งประกอบด้วยสอง ขั้วไฟฟ้า คือ ขั้วไฟฟ้าใช้งาน (Working electrode) และขั้วไฟฟ้าร่วม (Counter electrode) เพื่อให้ เกิดการก่อตัวของออกไซด์บนพื้นผิวแผ่นไทเทเนียม โดยออกไซด์ที่เกิดขึ้นจะมีรูปแบบลักษณะที่ แตกต่างกันออกไปตามแต่ชนิดของตัวกลาง และสภาวะในการสังเคราะห์

โดยขั้นตอนการสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยกระบวนการแอโนไดเซชันนั้น จะ ใช้แผ่นไทเทเนียมบริสุทธิ์ 99.5% หนา 0.25 มิลลิเมตร ตัดด้วยกรรไกรให้ได้ขนาด 1 × 4 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่รวม 4 ตารางเซนติเมตร โดยจุ่มแผ่นไทเทเนียมในสารละลายนำไฟฟ้าให้มีพื้นที่ที่เกิด ออกไซด์ขนาด 3 ตารางเซนติเมตร (กว้าง 1 เซนติเมตร ยาว 3 เซนติเมตร) ส่วนที่เหลือใช้ต่อเข้ากับ อุปกรณ์ในการกระบวนการแอโนไดเซชัน โดยมีขั้นตอนการสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์ดังต่อไปนี้

 การเตรียมแผ่นไทเทเนียมที่จะใช้ในการสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์ทำได้ ตามรูปที่ 3.2 โดยตัดแผ่นไทเทเนียมขนาดที่ต้องการ แล้วนำไปล้างด้วยเครื่องอัลตราโซนิค (Ultrasonic) 3 ขั้นตอน ใช้เวลาขั้นตอนละ 5 นาที คือ ล้างด้วยอะซิโตน (Acetone) ทู-โพรพานอล (2propanol) และน้ำปราศจากไอออน (Deionized water, DI) ตามลำดับ จากนั้นนำไปเป่าให้แห้งด้วย ก๊าซไนโตรเจนให้แห้งเพื่อไม่ให้เกิดออกไซด์อื่นบนพื้นผิวของไทเทเนียมก่อนการสังเคราะห์





#### รูปที่ 3.2 การเตรียมแผ่นไ<mark>ทเทเ</mark>นียมที่จะใช้ในการสัง<mark>เครา</mark>ะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์

2) การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยกระบวนการ แอโนไดเซชัน มีอุปกรณ์แสดงดังรูปที่ 3.3 ประกอบด้วย ชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้า (Power supply) โวลต์มิเตอร์ สายไฟ ไทเทเนียม (Tī) แพลทินัม (Pt) สารเคมีที่นำมาใช้เป็นสารละลายนำไฟฟ้า คือ แอมโมเนียมฟลูออไรด์ (NH4F) และ กลีเซอรอล (Glycerol) ในการทดลองจะใช้แผ่นไทเทเนียมมาเป็นขั้วไฟฟ้าใช้งาน (Working electrode) ต่อเข้ากับ ขั้วบวกของแหล่งจ่ายไฟฟ้า และใช้แพลทินัมเป็นขั้วไฟฟ้าร่วม (Counter electrode) ต่อเข้ากับ ขั้วบวกของแหล่งจ่ายไฟฟ้า และใช้แพลทินัมเป็นขั้วไฟฟ้าร่วม (Counter electrode) ต่อเข้ากับขั้วลบของ แหล่งจ่ายไฟฟ้า โดยจุ่มขั้วไฟฟ้าทั้งสองในสารละลายนำไฟฟ้า (Electrolyte) กำหนดความต่างศักย์ด้านสูงและต่ำ รวมถึงระยะเวลาตามที่ต้องการ หลังจากที่สังเคราะห์เสร็จแล้ว นำตัวเร่งปฏิกิริยาที่ได้ไปล้างให้สะอาดด้วยน้ำ DI เป่าให้แห้งด้วยก็าซ่ไนโตรเจน เพื่อไม่ให้เกิดออกไซด์อื่นบนพื้นผิวของไทเทเนียมหลังการสังเคราะห์ และนำไปเผา ที่อุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส เป็นเวลาสามสิบนาทีเพื่อให้คงคุณสมบัติของโครงสร้างของไทเทเนียมไดออกไซด์ แบบท่อนาโนที่ได้เป็นแบบอะนาเทส (Anatase) ก่อนนำไปใช้ในการวิเคราะห์หาค่าซีโอดีด้วยกระบวนการเร่ง ปฏิกิริยาด้วยแสงต่อไป แสดงวิธีการสังเคราะห์ใทเทเนียมไดออกไซด์ตามรูปที่ 3.4



รูปที่ 3.3 ลักษณะการสังเคราะห์ตัวเร่ง<mark>ปฏิกิริ</mark>ยาด้วยกระบวนการแอนโนไดเซชัน



รูปที่ 3.4 วิธีการสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยกระบวนการแอโนไดซ์

#### 3.1.1.1 การศึกษาผลของเวลาที่ใช้ในการสังเคราะห์แผ่นไทเทเนียมที่มีต่อลักษณะพื้นผิว ของไทเทเนียมไดออกไซด์รูปท่อที่เตรียมโดยการแอโนไดซ์แบบพัลส์

การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยกระบวนการแอโนไดเซซัน กำหนดให้ความเข้มข้นของ สารละลายนำไฟฟ้าเท่ากับ 0.30 โมลาร์ ของแอมโมเนียมฟลูออไรด์ ผสมด้วยกลีเซอรอลและน้ำในอัตราส่วน 60 : 40 (ศรัญญา ; 2555) จากนั้นทำการศึกษาค่าความต่างศักย์ด้านสูงและต่ำ รวมถึงระยะเวลาที่เหมาะสม ดังรูปที่ 3.5 จากนั้นนำไปวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวด้วยกล้อง FE-SEM ดูความหนาของชั้นออกไซด์ด้วย เครื่อง FIB-FESEM วิเคราะห์ Photocurrent density เพื่อวัดอิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นบนไทเทเนียมไดออกไซด์ รูปท่อที่เตรียมโดยการแอโนไดซ์แบบพัลส์ในรูปของกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการฉายแสงผ่านตัวเร่งปฏิกิริยา ในการตรวจสอบการตอบสนองต่อแสงของแผ่นนั้นใช้เทคนิค UV-VIS Spectrophotometer เพื่อดูว่า แผ่นตอบสนองในช่วง UV หรือ Visible สุดท้ายวิเคราะห์ X-ray Diffractrometer (XRD) เพื่อวิเคราะห์ โครงสร้างผลึกของออกไซด์ที่เกิดบนพื้นผิวไทเทเนียม ซึ่งเป็นการตรวจสอบว่าออกไซด์ที่เกิดขึ้นเป็น ไทเทเนียมไดออกไซด์โครงสร้างแบบอะนาเทส โดยสภาวะการทดลองมีดังตารางที่ 3.1

ลำดับ	สารละลายนำไฟฟ้า	สภาวะการสังเคราะห์	ระยะเวลา ทั้งหมด (ชั่วโมง)
1		20 โวลต์ 10 นาที/0 โวลต์ 20 วินาที	0 F
2		<mark>20 โวลต์ 10 นาที/-5</mark> โวลต์ <mark>2</mark> 0 วินาที	0.5
3		20 โวลต์ 10 นาที/0 โวลต์ 20 วินาที	1.0
4		20 โวลต์ 10 นาที/-5 โวลต์ 20 วินาที	1.0
5		20 โวลต์ 10 นาที/0 โวลต์ 20 วินาที	1 Г
6	6	<mark>20 โวลต์ 10 นาที/-5 โวลต์</mark> 20 วินาที	1.5
7	520	20 โวลต์ 10 นาที/0 โวลต์ 5 วินาที	
8		20 โวลต์ 5 นาที/0 โวลต์ 5 วินาที	
9	$0.30 \text{ M NH}_4\text{F}$ ,	20 โวลต์ 1 นาที/0 โวลต์ 5 วินาที	
10	Glycerol:H <sub>2</sub> O (60 :	20 โวลต์ 10 นาที/0 โวลต์ 20 วินาที	
11	40)	20 โวลต์ 5 นาที/0 โวลต์ 20 วินาที	
12		20 โวลต์ 1 นาที/0 โวลต์ 20 วินาที	2.0
13		20 โวลต์ 10 นาที/-5 โวลต์ 5 วินาที	5.0
14		20 โวลต์ 5 นาที/-5 โวลต์ 5 วินาที	
15		20 โวลต์ 1 นาที/-5 โวลต์ 5 วินาที	
16		20 โวลต์ 10 นาที/-5 โวลต์ 20 วินาที	
17		20 โวลต์ 5 นาที/-5 โวลต์ 20 วินาที	
18		20 โวลต์ 1 นาที/-5 โวลต์ 20 วินาที	

ตารางที่ 3.1 สภาวะทดลองเพื่อศึกษาผลของเวลาที่ใช้ในการสังเคราะห์แผ่นไทเทเนียมที่มีต่อลักษณะ พื้นผิวของไทเทเนียมไดออกไซด์รูปท่อที่เตรียมโดยการแอโนไดซ์แบบพัลส์



รูปที่ 3.5 ลักษณ<mark>ะการแอ</mark>โนไดซ์แบบพัลส์

#### 3.1.1.2 การหาค่าซีโอดี

ทำการศึกษาการหาค่าซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส โดยศึกษา เปรียบเทียบกับการทดลองชุดควบคุม 2 ชุด ได้แก่ ค่าซีโอดีที่คำนวณจากการเตรียมสารอินทรีย์ที่ให้ค่า ซีโอดีในเชิงทฤษฎี ได้แก่ กลูโคส (D-glucose) และโพแทสเซียมไฮโดรเจนพลาเลต (KHP) โดยที่กลูโคสใช้ เป็นตัวแทนของสารซีโอดีที่มีโซ่ตรงซึ่ง<mark>สาม</mark>ารถย่อยสลายได้ง่าย และโพแทสเซียมไฮโดรเจนพลาเลตใช้เป็น ตัวแทนของสารอินทรีย์ที่มีการย่อยสลายได้ยาก โครงสร้างแสดงดังรูปที่ 3.6



รูปที่ 3.6 โครงสร้างของกลูโคสและโพแทสเซียมไฮโดรเจนพลาเลต

นอกจากนั้นยังทำการเปรียบเทียบการวิเคราะห์หาค่าซีโอดีด้วยวิธีมาตรฐานไดโครเมต (COD<sub>cr</sub>) โดยที่มี ค่าซีโอดีไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังนี้

3.1.1.2.1 การทดลองชุดควบคุม

 เตรียมสารมาตรฐานซีโอดีจากน้ำตาลกลูโคสโดยชั่งสาร
469 มิลลิกรัม ละลายและเจือจางในน้ำปราศจากไอออนจนครบ 1 ลิตร จะได้สารละลายซีโอดีจาก กลูโคสที่ความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร จากนั้นจึงเจือจางให้ได้ความเข้มข้นที่ต้องการ และเตรียม สารมาตรฐานซีโอดีจากโพแทสเซียมไฮโดรเจนพลาเลต โดยชั่งสาร 425 มิลลิกรัม ที่ผ่านการอบที่
130 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง มาละลายและเจือจางในน้ำปราศจากไอออนจนครบ 1 ลิตร จะได้ สารละลายซีโอดีจากโพแทสเซียมไฮโดรเจนพลาเลต โดยชั่งสาร 425 มิลลิกรัม ที่ผ่านการอบที่

 2) การวิเคราะห์หาค่าซีโอดีด้วยวิธีมาตรฐานไดโครเมต (COD<sub>cr</sub>) ด้วยวิธี Closed Reflux/Titrimetric Method ทำได้โดยใช้ปริมาณน้ำตัวอย่างจากสารมาตรฐานซีโอดี 5 มิลลิลิตร สารละลายโปแตสเซียมไดโครเมต (K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>) ความเข้มข้น 0.1 นอร์มอล สำหรับย่อยสลาย 3 มิลลิลิตร แล้วค่อย ๆ เติมสารละลายกรดซัลฟิวริกที่มีซิลเวอร์ซัลเฟตผสมลงในหลอดย่อยสลาย 7 มิลลิลิตร ทำให้เกิดชั้นกรดที่ก้นหลอดแก้วย่อยสลายขนาด 20 x 150 มิลลิเมตร ปิดฝาให้แน่นพอดี แล้วแกว่งสารเพื่อให้สารผสมกันดี จากนั้นนำหลอดแก้วใส่ในขาตั้งแล้วนำไปอบที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ทิ้งให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง หยดด้วยเฟอร์โรอินอินดิเคเตอร์ 1-2 หยด แล้วนำมาทำการไตเตรทด้วย สารละลายมาตรฐานเฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟต (Ferrous Ammonim Sulfate; FAS) 0.025 นอร์มอล ขั้นตอนการวิเคราะห์ซีโอดีแสดงดังรูปที่ 3.7 จากนั้นการ คำนวณค่าซีโอดี ดังนี้

ซีโ<mark>อดี (มิลลิกรัมต่อ</mark>ลิตร) =

 $(A-B) \times N \times 8,000$ 

โดยที่

ปริมาตรของ FAS ที่ใช้ในการไตเตรทน้ำกลั่น (Blank) หน่วยเป็น มิลลิลิตร
ปริมาตรของ FAS ที่ใช้ในการไตเตรทน้ำตัวอย่าง หน่วยเป็น มิลลิลิตร
ความเข้มข้นของ FAS หน่วยเป็น นอร์มัลลิตี้ (N)
ปริมาตรน้ำตัวอย่างที่ใช้ หน่วยเป็นมิลลิลิตร



# รูปที่ 3.7 วิธีวิเคราะห์หาค่าซีโอดีด้วยวิธีมาตรฐานไดโครเมต

#### 3.1.1.2.2 การวิเคราะห์หาค่าซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส โดยใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้

ชุดการทดลองการวิเคราะห์หาค่าซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะ ตะไลซิสโดยใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์รูปท่อที่เตรียมโดยการแอโนไดเซซันแบบพัลส์นั้น จะใช้ ไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นขั้วไฟฟ้าใช้งาน (Working electrode) แพลตินัม (Pt) เป็นขั้วไฟฟ้าคู่ใช้งาน (Counter electrode) และใช้ Ag/AgCl เป็นขั้วไฟฟ้าอ้างอิง (Reference electrode) แหล่งกำเนิดแสง ใช้หลอดไฟ LCD (ความยาวคลื่น 365 นาโนเมตร) ขนาด 5 วัตต์ ซึ่งจะมีชุดการทดลองทั้งหมด 3 ชุด ดังนี้

### <u>ชุดการทดลองที่ 1</u>

ตัวถังปฏิกิริยาเป็นรูปทรงกระบอก ฐานรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า แสดง ดังรูป 3.8 ซึ่งตัวถังปฏิกิริยากับฐานจะแยกกัน เพื่อให้สามารถวางตัวเร่งปฏิกิริยาได้ โดยทำการเซาะร่อง วางโอริง (O-Ring) เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำซึมออกจากตัวถังปฏิกิริยา จากนั้นจะไขน็อตด้านล่างให้แน่นเพื่อ ยึดฐานกับตัวถังปฏิกิริยา ชุดการทดลองนี้ทำจากเทฟลอน (Teflon) ปริมาตรน้ำที่ใส่ได้ตั้งแต่ 5 – 30 มิลลิลิตร แหล่งกำเนิดแสงจะติดกับฝาปิดของถังปฏิกิริยาเพื่อป้องกันไม่ให้หลอดไฟนั้นสัมผัสกับน้ำ โดย ตัวเร่งปฏิกิริยาจะใช้พื้นที่ 1 ตารางเซนติเมตร



รูปที่ 3.8 ถังปฏิกรณ์ชุดการทดลองที่ 1

การวัดซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสด้วยชุดการ

ทดลองที่ 1 นั้น จะทำการจ่ายค่าความต่างศักย์ (V) และวัดค่ากระแสไฟฟ้า (I) ด้วยเครื่องมือที่ทำการ ประกอบขึ้นมา แสดงดังรูป 3.9 เครื่องนี้สามารถจ่ายความต่างศักย์ได้ตั้งแต่ 0.1 โวลต์ – 5.0 โวลต์ โดย สามารถจ่ายความต่างศักย์เป็นระยะเวลาต่อเนื่องถึง 5 นาที และสามารถเก็บข้อมูลในรูปของ ึกระแสไฟฟ้าได้ทุก ๆ 0.05 วินาที หน่วยความละเอียดในการวัดได้ต่ำสุดคือมิลลิแอมป์ (mA)

ถังปฏิกรณ์ของชุดการทดลองที่ 1 เมื่อทดลองจะไม่ใช้หัวหนีบปาก ้จระเข้คีบที่ขั้วใช้งาน (Working electrode) และขั้วไฟฟ้าช่วย (Counter electrode) โดยตรง ส่งผล

ให้ค่ากระแสไฟฟ้าที่วัดได้ระหว่าง Blank และสารละลายมาตรฐานมีค่าไม่แตกต่างกัน



รูปที่ 3.9 เครื่องมื<mark>อที่ใ</mark>ช้จ่<mark>ายค่าความต่างศักย์และวัด</mark>ค่าก<mark>ระแส</mark>ไฟฟ้าที่สร้างขึ้น

# <u>ชุดการทดลองที่ 2</u>

<u>ขุดการพดลองพ 2</u> เป็นการแก้ปัญหาที่เกิดจากถังปฏิกรณ์ของชุดการทดลองที่ 1 โดยใน ชุดการทดลองนี้ ถังปฏิกรณ์ทำจากซิลิโคน แสดงดังรูป 3.10 (ก) พื้นที่ของตัวเร่งปฏิกิริยาที่สัมผัสกับน้ำ 1 ตารางเซนติเมตร แหล่งกำเนิดแสงจะติดกับพลาสติกที่ทำการฉีดขึ้นรูป ซึ่งสามารถครอบถังปฏิกรณ์ ไว้ได้พอดี แสดงดังรูป 3.10 (ข) ถังปฏิกรณ์นี้สามารถใส่น้ำได้ตั้งแต่ 2 -5 มิลลิลิตร และในการวัดซีโอดี ด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสด้วยชุดการทดลองนี้ จะใช้เครื่องมือที่ใช้จ่ายค่าความต่าง ศักย์และวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่สร้างขึ้น (รูป 3.9)

ในชุดการทดลองที่ 2 เมื่อนำข้อมูลกระกระแสไฟฟ้าที่วัดได้จาก Blank และสารละลายมาตรฐาน มาพล็อตกราฟ พบว่า กราฟที่ได้นั้นออกมาเป็นเส้นเดียวกัน



รูปที่ 3.1<mark>0 ถังปฏิกรณ์ชุดการทด</mark>ลองที่ 2

# <u>ชุดการทดลองที่ 3</u>

จากชุดการทดลองที่ 2 (รูป3.10) แต่ในการวัดซีโอดีด้วย กระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสนั้น จะทำการจ่ายค่าความต่างศักย์ด้วยเครื่องมือที่ใช้จ่ายค่า ความต่างศักย์และวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่สร้างขึ้น (รูป 3.9) ในส่วนของการวัดกระแสนั้น จะวัดด้วยเครื่อง ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ รุ่น keysight 34465a แสดงดังรูปที่ 3.11 เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากชุดการทดลอง ที่ 2 ซึ่งเครื่องมือวัดกระแสนี้สามารถวัดได้เร็วถึง 50,000 rdgs/sec ทำให้ข้อมูลที่ได้นั้นมีความละเอียด มากพอที่จะทำให้การคำนวณหาพื้นที่ใต้กราฟนั้นมีความแม่นยำมากขึ้น



รูปที่ 3.11 เครื่องดิจิตอล มัลติมิเตอร์ รุ่<mark>น k</mark>eysight 34465a ที่ใช้ในการวัดกระแส (https://www.meil<mark>haus.de</mark>/en/34465a.htm)

#### 3.1.1.2.3 ตรวจสอบค<mark>วามถูกต้องแม่นยำและความเสถียรของวิธีการหา</mark> ค่าซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะ<mark>ตะไ</mark>ลซิส

ในการตรวจสอบความถูกต้อง แม่นยำ และความเสถียรของวิธีการ หาค่าซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสนั้น จะทำการแบ่งขั้นตอนการทดลองตามชุดการ ชุดการทดลองทั้ง 3 โดย โดยแต่ละชุ<mark>ด</mark>การทดลองนั้น มีขั้นตอนดังนี้

#### <mark>ชุดการทดลองที่ 1</mark>

เป็นการทดสอบการวัดค่าซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส เบื้องต้น โดยจะทำการแปรเปลี่ยนค่าความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานกลูโคส (D-glucose) ตั้งแต่ 1 – 500 มิลลิกรัมต่อลิตร และทำการกำหนดค่าความต่างศักย์ที่ใช้ 0.5 โวลต์ ปริมาตรน้ำ 5 มิลลิลิตร โดยใช้โซเดียมซัลเฟต (Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) 0.1 M เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งจะใช้แผ่นไทเทเนียมไดออกไซด์ 1 แผ่นต่อการทดลอง 1 ชุดข้อมูล

#### <u>ชุดการทดลองที่ 2</u>

ในการวัดค่าซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสนั้น จะต้องทำการหาสภาวะต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อที่จะให้การวัดนั้นแม่นยำและมีประสิทธิภาพ โดยทุก การทดลองนั้นจะใช้แผ่นไทเทเนียมไดออกไซด์ 1 แผ่น ต่อการทดลอง 1 ชุดข้อมูล ซึ่งแต่ละสภาวะมีการ ทดลองดังต่อไปนี้

#### สึกษาประเภทของสารละลายอิเล็กโทรไลต์

ในการทดลองหาค่าซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตร

คะตะไลซิสนั้น จะต้องทำการเติมสารละลายอิเล็กโทรไลต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำไฟฟ้าของ ระบบ (03, ref) โดยสารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่จะใช้ทดสอบมี 2 ชนิด คือ โซเดียมซัลเฟต (Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) และ โซเดียมไดไฮโดรเจนฟอตเฟต (NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>) ซึ่งสภาวะที่ทำการทดลองแสดงดังตารางที่ 3.2

โฟโตอิเล็กโตรคะตะไล	าซิส		
สารละลายมาตรฐาน	ความเข้มข้น สารละลายอิเล็กโทรไลต์	ความต่างศักย์ (โวลต์)	ปริมาตรน้ำ (มิลลิลิตร)
ວວໂຄສ 100 ມີວວີວຮັບຫ່ວວີຫະ	Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 1.0 โมลาร์	0 F	2
ពតូរកាត 100 អតតពររង២០ត២រ	NaH₂PO₄ 1.0 โมลาร์	0.5	5

ตารางที่ 3.2	สภาวะทดลองเพื่อศึกษาประเภทของสารอิเล็กโทรไลต์ที่เหมาะสมต่อกระบวนการ
	โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส

หมายเหตุ , ขั้วไฟฟ้าร่วมที่ใช้ คือ แผ่นแกรไฟต์

#### สึกษาความต่างศักย์ที่เหมาะสม

เพื่อให้อิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นที่แถบคอนดักชันเกิดการไหล จากขั้วไฟฟ้าแอนโนดไปยังขั้วไฟฟ้าแคโทด นอกจากนี้ยังช่วยเร่งการไหลของอิเล็กตรอนระหว่าง ขั้วไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญยังช่วยป้องกันการกลับมารวมตัวกันใหม่ของคู่อิเล็กตรอนและโฮล หรือที่เรียกว่า Recombination (04 05, ref) ซึ่งในการทดลองนั้นจะทำการแปรเปลี่ยนค่าความต่าง ศักย์ที่ความเข้มข้นของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ต่าง ๆ ดั<mark>ง</mark>ตารางที่ 3.3

ตารางที่ 3.3 สภาวะทดลองเพื่อศึกษาความ<mark>ต่าง</mark>ศักย์ที่เหม<mark>าะส</mark>มต่อกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส

สารละลายมาตรฐาน	ความเข้มข้น ส <mark>า</mark> รละลายอิเล็กโทรไล <mark>ต์</mark>	ความต่างศักย์ (โวลต์)	ปริมาตรน้ำ (มิลลิลิตร)
		0.5	
กลูโคส 100 มิลลิกรัมต่อลิตร	Na2SO4 0.1 เมสาว	2.0	3
	Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 0.5 โมลาร์	0.5	
		2.0	
		0.5	
	Na2SO4 1.0 เมลาว	2.0	

้หมายเหตุ , ขั้วไฟฟ้าร่วมที่ใช้ คือ แผ่นแกรไฟต์

# ยาลัยเทคโนโลยีสุรุ่น

# 3) ศึกษาประเภทของขั้วไฟฟ้าร่วม (Counter electrode) นอกจากประเภทของสารละลายอิเล็กโทรไลต์กับค่าความ

ต่างศัยก์ที่ส่งผลต่อปริมาณกระแสไฟฟ้าที่เกิดแล้ว สิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือประเภทของขั้วไฟฟ้าร่วม เนื่องจากทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี จะทำหน้าที่รับพลังงานไฟฟ้าจากขั้วไฟฟ้าใช้งาน (Working electrode) เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมีของสารตัวอย่างระหว่างการวิเคราะห์ ขั้วไฟฟ้าใช้งานมักมีพื้นที่ผิว มาก ๆ เพื่อให้การนำไฟฟ้าเป็นไปได้ดี (06 07, ref) ซึ่งในการทดลองนี้จะใช้วัสดุ 2 ชนิด ได้แก่ ลวด แพลทินัม และแผ่นแกรไฟต์ โดยมีการทดลองแสดงดังตารางที่ 3.4

ตารางที่ 3.4	สภาวะทดลองเพื่อศึกษาประเภทของขั้วไฟฟ้าร่วมที่ส่งผลต่อกระบวนการโฟโตอิเล็กโตร
	คะตะไลซิส

สารละลายมาตรฐาน	ความเข้มข้น สารละลายอิเล็กโทรไลต์	ขั้วไฟฟ้าร่วม	ความต่างศักย์ (โวลต์)
กลูโคส 100 มิลลิกรัมต่อลิตร	Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 1.0 โมลาร์	ลวดแพลทินัม	0 F
		แผ่นแกรไฟต์	0.5

หมายเหตุ , ปริมาตรน้ำที่ใช้ 3 มิลลิลิตร

# <u>ชุดการทดลองที่ 3</u>

เนื่องจากปัญหาที่เกิดในชุดการทดลองที่ 2 ดังที่ได้กล่าวในหัวข้อ 3.2.1.2. จึงได้ทำการหาสภาวะต่าง ๆ ที่เหมาะส<mark>มใ</mark>หม่ ซึ่งทุกการทดลองจะใช้ขั้วไฟฟ้าร่วมคือ ลวด แพลทินัม โดยมีการทดลองดังต่อไปนี้

1) ศึกษาความต่างศักย์ที่เหมาะสม แสดงดังตารางที่ 3.5

ตารางที่ 3.5 สภาวะทดลองเพื่อศึกษาความ<mark>ต่</mark>างศักย์<mark>ที่เห</mark>มาะสมของชุดการทดลองที่ 3 ส่งผลต่อ กระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะ<mark>ตะไ</mark>ลซิส

สารละลายมาตรฐาน	ความเข้มข้น <mark>สา</mark> รละลายอิเล็กโทรไล <mark>ต์</mark>	ความต่างศักย์ (โวลต์)	ปริมาตรน้ำ (มิลลิลิตร)
		0.1	
		0.2	
		0.3	2
กถึงแย่ 10 ทยอบเรทุดออดเร	Na2304 0.1 เมตาง	0.4	5
		0.5	
C		1.0	

หมายเหตุ , 1. คีบสายไฟใหม่ทุกครั้ง

2. ใช้แผ่นไทเทเนียมไดออกไซด์ 1 แผ่น ต่อ 1 ความต่างศักย์

หาค่าซีโอดีด้วยวิธีการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส

เมื่อได้สภาวะที่เหมาะสมจากตารางที่ 3.5 แล้ว จึงได้ทำการ

หาค่าซีโอดีด้วยวิธีการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส โดยใช้สารละลายมาตรฐานกลูโคสความเข้มข้นต่าง ๆ เป็นตัวแทนน้ำเสีย แสดงดังตารางที่ 3.6

ตารางที่ 3.6	สารละลายมาตรฐานกลูโคสความเข้มข้นต่าง ๆ ที่ใช้เป็นตัวแทนน้ำเสียในการหาค่าซีโอดี
	ด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส

สารละลายมาตรฐาน	ความเข้มข้น สารละลายอิเล็กโทรไลต์	ความต่างศักย์ (โวลต์)	ปริมาตรน้ำ (มิลลิลิตร)
กลูโคส 5 มิลลิกรัมต่อลิตร			
กลูโคส 10 มิลลิกรัมต่อลิตร			
กลูโคส 50 มิลลิกรัมต่อลิตร		a	
กลูโคส 75 มิลลิกรัมต่อลิตร	Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 0.1 โมลาร์	สมาวองเพื่ว เ	3
กลูโคส 100 มิลลิกรัมต่อลิตร		0.2 11 01 0.2	
กลูโคส 200 มิลลิกรัมต่อลิตร			
กลูโคส 500 มิลลิกรัมต่อลิตร			

หมายเหตุ , 1. คีบสายไฟใหม่ทุกครั้ง

คิบสายไฟไหม่ทุกครัง
ใช้แผ่นไทเทเนียมไดออกไซด์ 1 แผ่น ต่อทุกความเข้มข้น

จากการทดลองนี้พบว่าปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ได้จากสารละลาย มาตรฐานกลูโคสส่วนใหญ่จะมีค่าต่ำกว่าประมาณกระแสที่ได้จาก Blank จึงได้ตั้งสมมติฐานว่าอาจเกิด จากการที่ใช้แผ่นไทเทเนียมเพียงแผ่นเดียวต่อทุกความเข้มข้น ส่งผลให้แผ่นนั้นหมดสภาพ จากการ ทดลองการหาค่าซีโอดีด้วยวิธีการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสดังตารางที่ 3.6 แล้วเกิดปัญหา จึงได้ทำการ ทดสอบสมมติฐานโดยใช้แผ่นไทเทเนียมไดออกไซด์ใหม่ทุกครั้งที่เปลี่ยนความเข้มข้นของสารละลาย มาตรฐาน โดยการทดลองมีดังตารางที่ 3.7

ตารางที่ 3.7 สารละลายมาต<mark>รฐานก</mark>ลูโคสความเข้มข้นต่าง ๆ ที่ใช้เป็นตัวแทนน้ำเสียในการหาค่าซีโอดี ด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส

สารละลายมาตรฐาน	<mark>ความเข้มข้น</mark> สารละลายอิเล็กโทรไลต์	ความต่างศักย์ (โวลต์)	ปริมาตรน้ำ (มิลลิลิตร)
กลูโคส 5 มิลลิกรัมต่อลิตร	ยาลัยเทคโบโลยี	3.5	
กลูโคส 10 มิลลิกรัมต่อลิตร			
กลูโคส 50 มิลลิกรัมต่อลิตร		สภาวะที่ได้จาก	2
กลูโคส 100 มิลลิกรัมต่อลิตร	Na2SO4 0.1 เมลาว	ตารางที่ 3.6	5
กลูโคส 200 มิลลิกรัมต่อลิตร			
กลูโคส 500 มิลลิกรัมต่อลิตร			

หมายเหตุ , 1. คีบสายไฟใหม่ทุกครั้ง

จากการทดลองนี้ได้ทำการตรวจเช็คกราฟที่ได้จาก Blank พบว่าแต่ ละซ้ำ กราฟที่ได้ไม่เป็นเส้นเดียวกัน จึงตั้งสมมติฐานว่าอาจเกิดจากการที่คีบสายไฟใหม่ทุกครั้ง (ไม่ใช่ ตำแหน่งเดิม) โดยได้ทดสอบสมมติฐานโดยทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำตัวอย่างจะใช้ Dropper ในการนำน้ำ ตัวอย่างออก เพื่อให้สายไฟอยู่ตำแหน่งเดิม

นอกจากนี้ซีโอดีที่ได้จากกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสนั้น มีค่าไม่เท่ากับค่าซีโอดีทางทฤษฏี จึงได้ทำการเปลี่ยนสารละลายมาตรฐานจากสารละลายมาตรฐาน กลูโคส และเป็นสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลท (KHP) ทดลองความเข้มข้นต่าง ๆ เพื่อนำไปสร้างกราฟมาตรฐาน (08, ref) การทดลองแสดงดังตารางที่ 3.8 โดยในการทดลองนี้ได้ทำการ ซ้ำทั้งหมด 3 ครั้ง เพื่อดูความถูกต้องและแม่นยำ

ิตารางที่ 3.8 สารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไฮ<mark>โดร</mark>เจนพทาเลท (KHP) ความเข้มข้นต่าง ๆ ที่ใช้เป็น ตัวแทนน้ำเสียในการหาค่าซีโอดีด้วย<mark>กระ</mark>บวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส

	คว <mark>ามเข้มข้</mark> น	ความต่างศักย์	ปริมาตรน้ำ
สารสะสายมาตรฐาน	สารละล <mark>า</mark> ยอิเล็ก <mark>โ</mark> ทรไลต์	(โวลต์)	(ມີຄຄີຄືตร)
KHP 5 มิลลิกรัมต่อลิตร			
KHP 10 มิลลิกรัมต่อลิตร		สภาวะที่ได้จาก ตารางที่ 3.6	3
KHP 20 มิลลิกรัมต่อลิตร			
KHP 50 มิลลิกรัมต่อลิตร			
KHP 100 มิลลิกรัมต่อลิตร			
KHP 150 มิลลิกรัมต่อลิตร 🛛 🛁	Na₂SO₄ 0.1 โมลาร์		
KHP 200 มิลลิกรัมต่อลิตร 🧦			
KHP 250 มิลลิกรัมต่อลิตร 🧹			
KHP 300 มิลลิกรัมต่อลิตร 💙			
KHP 400 มิลลิกรัมต่อลิตร			
KHP 500 มิลลิกรัมต่อลิตร			
· Jh	ยาลัยเทคโนโลยี่	12,5	

#### 3.2 ซิงค์ออกไซด์

#### 3.2.1 สังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ด้วยกระบวนการแอโนไดเซชัน

การสังเคราะห์ตัวเร<sup>ิ่</sup>งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ด้วยกระบวนการแอโนไดเซชัน ทำโดยการ ตัดแผ่นซิงค์ที่มีความหนา 0.25 มิลลิเมตร บริสุทธิ์ 99.98% (บริษัท Alfa Aesar) ให้มีขนาดกว้าง 1 เซนติเมตรและยาว 4 เซนติเมตร แล้วนำไปล้างในเครื่องอัลตราโซนิค (Ultrasonic) 2 ขั้นตอน คือล้าง ด้วยอะซิโตน (Acetone) และน้ำปราศจากไอออน ขั้นตอนละ 15 นาทีตามลำดับ จากนั้นนำไปเป่าให้ แห้งด้วยก๊าซไนโตรเจน (Farrukh, Thong et al., 2012) เพื่อไม่ให้เกิดออกไซด์อื่นบนพื้นผิวของซิงค์ ก่อนการสังเคราะห์ จากนั้นนำซิงค์พื้นที่สำหรับการทำให้เกิดออกไซด์อื่นบนพื้นผิวของซิงค์ ก่อนการสังเคราะห์ จากนั้นนำซิงค์พื้นที่สำหรับการทำให้เกิดออกไซด์ขนาด 3 ตารางเซนติเมตรจุ่ม สัมผัสกับสารละลายนำไฟฟ้า (Electrolyte) จ่ายความต่างศักย์ไฟฟ้าแก่โลหะโดยจ่ายจากแหล่งกำเนิด ไปสู่เซลล์เคมีไฟฟ้า (Electrodechemical cell) ซึ่งประกอบด้วย 2 ขั้วไฟฟ้า คือ ขั้วไฟฟ้าใช้งาน (Working electrode) และขั้วไฟฟ้าร่วม (Counter electrode) โดยใช้แผ่นโลหะเป็นขั้วไฟฟ้าใช้งาน ต่อเข้ากับขั้วบวกของแหล่งจ่ายไฟฟ้าในที่นี้ คือ โลหะซิงค์ (Zn) และใช้แพลทินัม (Pt) เป็นขั้วไฟฟ้าร่วม ต่อเข้ากับขั้วลบของแหล่งจ่ายไฟฟ้า โดยจุ่มขั้วไฟฟ้าทั้งสองในสารละลายนำไฟฟ้า เพื่อให้เกิดการก่อตัว ของออกไซด์บนพื้นผิวซิงค์ออกไซด์ขนาด 3 ตารางเซนติเมตร แสดงลักษณะการทดลอง ดังรูปที่ 3.12



รูปที่ 3.12 ลักษณะการทดลองการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์

โดยออกไซด์ที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามชนิดของตัวเร่งปฏิกิริยาและ สภาวะในการสังเคราะห์ ทำการกำหนดความต่างศักย์ และระยะเวลาที่ต้องการใช้ในการแอโนไดเซชัน ดังตารางที่ 3.9 หลังจากที่สังเคราะห์เสร็จแล้วนำตัวเร่งปฏิกิริยาที่ได้ไปล้างให้สะอาดด้วย น้ำปราศจากไอออน (Deionized water; DI) เป่าให้แห้งด้วยก๊าซไนโตรเจน เพื่อไม่ให้เกิดออกไซด์อื่น บนพื้นผิวของซิงค์ออกไซด์หลังการสังเคราะห์ วิธีการสังเคราะห์ซิงค์ออกไซด์ แสดงดังรูปที่ 3.13

ลำดับที่	สารละลายนำไฟฟ้า	ความต่างศักย์ (โวลต์)	ระยะเวลา (นาที)
1			5
2		1	10
3			30
4			5
5	NH₄F 0. <b>2 โม</b> ลาร์	3	10
6			30
7			60
8			120
9	E I	R	5
10		5	10
11			30
12			5
13		10	10
14			30
15 🗸		20	<b>9</b> 5
	15.	- sgu	

ตารางที่ 3.9 สภาวะการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ด้วยกระบวนการแอโนไดเซชัน

<sup>อกย</sup>าลัยเทคโนโลยี<sup>ลุจ</sup>


รูปที่ 3.13 วิธี<mark>การสังเคราะห์ซิงค์ออกไซด์ด้วยกระ</mark>บวนการแอโนไดเซชัน



#### 3.2.2 สังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ด้วยกระบวนการสปัตเตอริง

้วิธีการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ด้วยกระบวนการสปัตเตอริง ดังรูปที่ 3.14<sup>1</sup> ทำโดยการตัดแผ่นฐานรองรับ (Substrate) ขนาดกว้าง 5 เซนติเมตรและยาว 5 เซนติเมตร แล้ว ้นำไปล้างด้วยอะซีโตน (Acetone) ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (Iso Propyl Alcohol, (IPA) ขั้นตอนละ 5 นาที ตามลำดับ จากนั้นนำไปล้างด้วยน้ำปราศจากไอออน และเป่าให้แห้งด้วยก๊าซไนโตรเจน ติดเข้า กับกระจกเพื่อตรึงฐานรองรับให้อยู่กับที่ นำไปอบที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ติด พลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) ครึ่งหนึ่งของพื้นที่ฐานรองรับเพื่อให้การสปัตเตอริงของ ้ซิงค์ออกไซด์เคลือบติดลงที่ฐานรองรับเพียงครึ่งเดียว (ในภายหลังได้ได้เปลี่ยนไปใช้กระบวนการ ์ โฟโตลิโธกราฟี (Photolithography) ในการเตรียมฐานรองรับเพื่อควบคุมพื้นที่ของซิงค์ออกไซด์ให้ได้ ขนาดที่แน่นอน โดยนำแผ่นฐานรองรับ (Substrate) ขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร และยาว 5 เซนติเมตร ไป ้ล้างทำความสะอาดดังวิธีข้างต้น จากนั้นนำไปเคลื<mark>อบ</mark>ด้วยสารไวแสงชนิดบวก AZ9260 ที่ความเร็วรอบ 2 รอบ คือ ที่ความเร็วรอบ 500 rpm 10 วินาที แล<mark>ะ</mark> 4,000 rpm 40 วินาที ตามลำดับ นำแผ่นที่เคลือบ ้สารไวแสงไปอบที่อุณหภูมิประมาณ 100 องศา<mark>เซลเซีย</mark>ส เพื่อทำให้น้ำยาไวแสงยึดติดกับผิวหน้าของ แผ่นฐานรองรับหลังจากนั้นจะนำไปฉายด้วยแส<mark>ง</mark>อัลตราไวโอเล็ต ผ่านโฟโตมาส์ค (Photo Mask) ไปตก กระทบบนแผ่นฐานรองรับเพื่อให้เกิดรูปแบบที่ต้องการ จากนั้นล้างด้วยน้ำยา AZ Developer และล้าง ้ด้วยน้ำปราศจากไอออน เป่าให้แห้งด้ว<mark>ยก้า</mark>ซไนโตร<mark>เจน</mark> และอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ้ส่วนที่ไม่ได้ถูกฉายด้วยรังสีจะ ยังคงอยู่บน<mark>ฐาน</mark>รองรับแต่<mark>ส่วน</mark>ที่โดนฉายด้วยรังสีจะหลุดออก (ศุภกิตติ์ พรหมวิกร, 2552) ซึ่งมีวิธีการดังรูปที่ <mark>3.14</mark>²) ก่อนนำไปเข้าห้<mark>องเ</mark>คลือบด้วยกระบวนการสปัตเตอริง ซึ่ง ระบบสปัตเตอริงจะประกอบไปด้วยคู่ของขั้วไฟฟ้าแบบระนาบ แสดงดังรูปที่ 3.15 โดยขั้วไฟฟ้าหนึ่งเป็น แคโทดเย็น (cold cathode) ที่ผิวหน้าของแคโทดจะถูกปิดด้วยสารที่เป็นเป้าที่จะเป็นสารเคลือบ และ ้ อีกขั้วหนึ่งเป็นแอโนด (anode<mark>) ซึ่ง</mark>จะ<mark>มีส่วนของชิ้นงานหรือฐานร</mark>องรั<mark>บท</mark>ี่ต้องการเคลือบวางอยู่ จากนั้น ทำการลดความดันภายในห้อ<mark>งเคล</mark>ือบ<mark>จนเป็นความดันสุญญากา</mark>ศอยู่ใ<mark>นช่ว</mark>ง 10⁻⁵ ถึง 10⁻⁰ ทอร์ เมื่อได้ ความดันอยู่ในช่วงที่กำหนด<mark>แล้ว ทำ</mark>การเติมก๊าซอาร์กอนลงไปในห้องเคลือบจนความดันประมาณ 2x10<sup>-2</sup> ทอร์ จึงเริ่มทำการสปัต<mark>เตอริงซิงค์ออกไซด์ที่กำลังไฟฟ้า 50 วัตต์</mark> ตามระยะเวลาที่ต้องการ ซึ่งมี ้สภาวะในการทดลองดังตารางที่ 3.<mark>10 โดยที่มีการพักการสปัตเตอ</mark>ริงเป็นช่วง ๆ ช่วงละ 5 นาที เพื่อ ้ป้องกันการเกิดการอาร์คจากความร้อนในขณะที่ทำการเคลือบ ก๊าซอาร์กอนจะแตกตัวเป็นไอออน (พลาสม่า) ด้วยสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าพุ่งชนไปที่เป้าและสปัตเตอร์เป้า เป็นผลให้ได้อะตอมเป้า หลุดออกไปสู่ชิ้นงานแล้วก่อตัวเป็นฟิล์มบางบนชิ้นงาน แล้วจึงเป่าให้ด้วยก๊าซไนโตรเจนก่อนการ นำไปใช้งานต่อไป



รูปที่ 3.14<sup>1</sup> วิธีการสังเคราะห์ซิงค์ออกไซด์ด้วยกระบวนการสปัตเตอริง



รูปที่ 3.14<sup>2</sup> วิธีการสังเคราะห์ซิงค์ออกไซด์ด้วยกระบวนการสปัตเตอริง



รูปที่ 3.15 ลักษณะการทดลองการสังเคราะห์ตัวเร<mark>่งป</mark>ฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ด้วยกระบวนการสปัตเตอริง

ลำดับที่	กำลัง <mark>ไ</mark> ฟฟ้า ( <mark>ว</mark> ัตต์)	ระยะเวลา (นาที)			
1		60			
2		120			
3	50	240			
1		180			

ตารางที่ 3.10 สภาวะการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริ<mark>ยาซิงค์อ</mark>อกไซด์ด้วยกระบวนการสปัตเตอริง

#### 3.2.3 ศึกษาคุณลัก<mark>ษณ</mark>ะต่<mark>าง ๆ ของซิงค์ออกไซด์</mark>

นำตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ที่ได้จากการสังเคราะห์ที่สภาวะต่าง ๆ ศึกษา คุณลักษณะโดยส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดความละเอียดสูง (Field emission scanning electron microscope; FESEM) เพื่อศึกษาคุณลักษณะพื้นผิวของซิงค์ออกไซด์ วิเคราะห์ ความขรุขระด้วยกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม (Atomic force microscope, AFM) ศึกษาความหนา ด้วยเครื่องวัดความหนาฟิล์มด้วยแสง (Optical profiler) วิเคราะห์ความเป็นผลึกหรือเฟสของตัวเร่ง ปฏิกิริยาด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ดิฟแฟรคโทมิเตอร์ (X-ray diffractometer, XRD) วิเคราะห์ชนิดและ สถานะทางเคมีของธาตุที่เป็นองค์ประกอบที่เกิดบนพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยเครื่องวิเคราะห์ผิว วัสดุ (X-ray Photoelectron Spectroscopy, XPS) วิเคราะห์การตอบสนองของปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี แสง (Photoelectrochemistry) เพื่ออธิบายความสามารถของตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ในการ ตอบสนองต่อแหล่งกำเนิดแสง โดยใช้วิธีการวัดอิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นในรูปของความหนาแน่นของ กระแสไฟฟ้าจากการกระตุ้นด้วยแสง (Photocurrent density) หลังจากการกระตุ้นด้วยการฉายแสงไป ยังตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ และวิเคราะห์การดูดกลืนแสงของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยเครื่องรางรายแสงไป ยังตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ และวิเคราะห์การดูดกลืนแสงของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยเครื่องตรวจวัดสาร ด้วยการดูดกลืนแสง (UV-VIS Spectrophotometer) รายละเอียดดังภาคผนวก ก เพื่อเป็นข้อมูล สนับสนุนในการเลือกตัวแทนของตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์เพื่อนำไปใช้วัดซึโอดี

#### 3.2.4 การหาค่าซีโอดี

#### 3.2.4.1 ศึกษาการตอบสนองต่อแสงของตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ ด้วยกระบวนการแอโนไดเซชัน

ทำการศึกษาการตอบสนองต่อแสง อาศัยหลักการของเซลล์ไฟฟ้าเคมี ประกอบด้วยเซลล์ไฟฟ้า 3 ขั้ว โดยมีซิงค์ออกไซด์ขนาด 1x 4 ตารางเซนติเมตร พื้นที่ใช้งานจริง 1x1 ตารางเซนติเมตร พื้นที่ 1x2 ตารางเซนติเมตร ใช้แคปตอนเทปติดป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปฏิกิริยา และ พื้นที่ 1x1 ตารางเซนติเมตร ที่เหลือ ต่อเข้ากับสายไฟเป็นขั้วไฟฟ้าใช้งาน (Working electrode) แพลทินัม (Pt) เป็นขั้วไฟฟ้าร่วม (Counter electrode) และ Ag/AgCl เป็นขั้วไฟฟ้าอ้างอิง (Reference electrode) ทำการจุ่มขั้วไฟฟ้าทั้ง 3 ลงในสารละลายโซเดียมซัลเฟต (Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) ความเข้มข้น 0.5 โมลาร์ ปริมาณ 3 มิลลิลิตร และต่อขั้วไฟฟ้าเข้ากับเครื่องโพเทนชิโอสแตท (Potentiostat, F9 SUT) จ่ายความต่างศักย์คงที่ 0.5 โวลต์ ฉายแสงจากหลอดยูวี (UV-LED) ของบริษัท LedEngin Inc ขนาด 10 วัตต์ ความยาวคลื่น 365 นาโนเมตร ไปยังตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ โดยทำการปิด-เปิดไฟสลับกันรอบ ละประมาณ 20 วินาที ลักษณะการทดลอง ดังรูปที่ 3.16



รูปที่ 3.16 ลักษณะการทดลองตอบสนองต่อแสงของตัวเร่งปฏิกิริยา

#### 3.2.4.2 ทำการตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำและความเสถียรของวิธีการหา ค่าซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสโดยใช้ซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการ แอโนไดเซชันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

กระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส คือ การนำกระบวนการโฟโตคะตะไลซิสมา ประยุกต์เข้ากับเซลล์ไฟฟ้าแบบ 3 ขั้ว โดยนำตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ต่อเป็นขั้วไฟฟ้าใช้ งาน (Working electrode) ใช้แกรไฟต์ (Graphite) หรือแพลทินัม (Pt) เป็นขั้วไฟฟ้าร่วม (Counter electrode) และใช้ Ag/AgCl เป็นขั้วไฟฟ้าอ้างอิง (Reference electrode) กล่าวคือ เมื่อมีการให้ พลังงานแสงจากหลอดยูวี (UV LED) แก่ตัวเร่งปฏิกิริยา ทำให้เกิดการกระตุ้นอิเล็กตรอนจนเกิดเป็นเรดิ คอล ที่มีความสามารถในการออกซิไดซ์สารอินทรีย์ได้ และมีการจ่ายความต่างศักย์ให้กับขั้วไฟฟ้าใช้งาน ด้วยในขณะฉายแสงเพื่อช่วยให้การออกซิไดซ์สารอินทรีย์เป็นไปอย่างสมบูรณ์มากขึ้น และสามารถวัดค่า ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและความต่างศักย์ของเซลล์ไฟฟ้าที่อยู่ในสารละลาย ดังแสดงในรูปที่ 3.17



#### รูปที่ 3.17 การหาค่าซี<mark>โอดี</mark>ด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส

นำกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสมาประยุกต์ใช้ในการหาค่าซีโอดีโดยทำ

การตรวจสอบความถูกต้องแม่น<mark>ยำ</mark>และ<mark>ความเสถียรขอ</mark>งวิธีการ <mark>มีขั้นตอนก</mark>ารศึกษาดังนี้

#### ทำการวัดค่าซีโอดีจากชุดเครื่องมือที่สร้างขึ้น

ชุดเครื่องมือที่นำมาใช้ในการวั<mark>ดซีโอด</mark>ีในส่วนของโพรบวัดทำจาก

เทฟลอน (Teflon) ประกอบไปด้วยเซลล์ไฟฟ้า 3 ขั้ว จุ่มลงในบีกเกอร์ขนาด 250 มิลลิลิตร ซึ่งใช้เป็น ถังปฏิกรณ์สำหรับใส่น้ำตัวอย่างได้ในช่วง 50-60 มิลลิลิตร ทำการฉายแสงไปยังตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ ด้วยหลอดยูวี (UV-LED) ขนาด 10 วัตต์ ความยาวคลื่น 365 นาโนเมตร ระยะห่างระหว่างตัวเร่ง ปฏิกิริยาและหลอดไฟ 2 เซนติเมตร และทำการจ่ายค่าความต่างศักย์ (V) และวัดค่ากระแสไฟฟ้า (I) ด้วย เครื่องมือที่ประกอบขึ้น ดังรูป 3.18 เครื่องนี้สามารถจ่ายความต่างศักย์ (O) และวัดค่ากระแสไฟฟ้า (I) ด้วย โดยสามารถจ่ายความต่างศักย์เป็นระยะเวลาต่อเนื่องสูงสุดที่ 5 นาที และสามารถเก็บข้อมูลในรูปของ กระแสไฟฟ้าได้ทุก ๆ 0.05 วินาที และวัดกระแสได้ต่ำสุดในระดับมิลลิแอมป์ (mA)



รูปที่ 3.18 เครื่องวัดซีโอดีที่สร้างขึ้น

#### 1.1) ทำการแปรผันความเข้มข้นของซีโอดี

ทำการวิเคราะห์หาค่าซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไล ซิส (COD<sub>PEC</sub>) ของสารมาตรฐานซีโอดีที่ความเข้มข้นที่ต่าง ๆ กัน คือ ซีโอดีจากสารละลายมาตรฐาน กลูโคส (D-glucose) ที่ความเข้มข้น 10 100 และ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ละความเข้มข้นของ ซีโอดี กลูโคสจะถูกผสมเข้ากับสารอิเล็กโทรไลต์โซเดียมซัลเฟต (Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) 0.1 โมลาร์ ใช้น้ำตัวอย่าง ปริมาณ 50 มิลลิลิตร และจ่ายความต่างศักย์คงที่ 0.5 โวลต์ เป็นเวลา 5 นาที โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา ตัวเดียวสำหรับการวิเคราะห์แต่ละค่า เป็นการตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำ เทียบกับค่าซีโอดีตาม ทฤษฎี (COD<sub>Theory</sub>) สภาวะการทดลองแสดงดังตารางที่ 3.11

ตารางที่ 3.11 สภาวะการทดลองหาค่าซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสที่ซีโอดี ความเข้มข้นต่าง ๆ

สารอิเล็กโทรไลต์ (โมลาร์)	ความต่างศักย์ (โวลต์)	ปริมาณ <mark>น้ำตัวอ</mark> ย่าง (มิลลิลิตร)	ความเข้มข้นซีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ระยะเวลา ในการวัดซีโอดี (นาที)
			10	
0.1	0.5	50	100	5
			500	

<u>หมายเหตุ</u> ใช้แกรไฟต์เป็นขั้วไฟฟ้าร่วม

เนื่องจากในการทุดลองที่ผ่านมาใช้ปริมาณน้ำตัวอย่างค่อนข้างมาก

จึงทำการออกแบบชุดของถังปฏิกรณ์ใหม่เพื่อให้ใช้ปริมาณน้ำที่น้อยลง โดยที่ ถังปฏิกรณ์ใหม่นี้หล่อขึ้นรูปด้วยซิลิโคนขนาด 3x5 ตารางเซนติเมตร มีช่องสำหรับใส่ขั้วไฟฟ้าใช้งาน ขนาด1x1.5 ตารางเซนติเมตร ช่องใส่ขั้วไฟฟ้าร่วมขนาด 2x2 ตารางเซนติเมตร สามารถใส่ปริมาณน้ำ ตัวอย่างได้ 3-5 มิลลิลิตร ส่วนของแหล่งกำเนิดแสงถูกติดเข้ากับพลาสติกที่ฉีดขึ้นรูปที่สามารถวางครอบ กับตัวถังปฏิกรณ์ได้พอดี และส่วนบนของพลาสติกชิ้นนี้จะถูกเจาะรูสำหรับใส่ขั้วไฟฟ้าอ้างอิงขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร อุปกรณ์เป็นดังรูปที่ 3.19 ในส่วนของการฉายแสงยังคงใช้แหล่งกำเนิดแสง จากหลอดยูวีแอลอีดีดังเดิม และการจ่ายค่าความต่างศักย์ (V) กับการวัดค่ากระแสไฟฟ้า (I) ก็ยังคงใช้ เครื่องมือที่ประกอบขึ้นดังเดิมเช่นกัน



รูปที่ 3.19 ถังปฏิกรณ์สำหรับวัดซีโอดี

#### 1.2) ทำการแปรผันความเข้มข้นของสารอิเล็กโทรไลต์

หลังจากที่ทำการเปลี่ยนถังปฏิกรณ์เป็นแบบใหม่แล้ว ในการทดลอง การหาค่าซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสจำเป็นต้องเติมสารอิเล็กโทรไลต์ลงในน้ำตัวอย่าง เพื่อให้มีความสามารถในการนำไฟฟ้าได้ จึงทำการแปรผันความเข้มข้นของสารอิเล็กโทรไลต์ที่ใช้คือ โซเดียมซัลเฟต (Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) ใช้ซีโอดีจากกลูโคสความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตรปริมาณน้ำ 3 มิลลิลิตร จ่ายความต่างศักย์คงที่ 1.0 โวลต์ เป็นเวลา 5 นาที สภาวะการทดลองเป็นดังตารางที่ 3.12 ตารางที่ 3.12 สภาวะการทดลองหาค่าซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสที่ใช้ สารอิเล็กโทรไลต์โซเดียมซัลเฟตที่ความเข้มข้นต่าง ๆ

สารอิเล็กโทรไลต์ (โมลาร์)	ความต่างศักย์ (โวลต์)	ปริมาณน้ำตัวอย่าง (มิลลิลิตร)	ความเข้มข้นซีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ระยะเวลา ในการวัดซีโอดี (นาที)
0.1				
0.5	1.0	3	100	5
1.0				

<u>หมายเหตุ</u> ใช้แกรไฟต์เป็นขั้วไฟฟ้าร่วม

#### 1.3) ทำการแปรผันความต่างศักย์ไฟฟ้า

ทำการศึกษาความต่างศักย์ที่เหมาะสมเพื่อให้อิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นที่ แถบคอนดักชันเกิดการไหลจากขั้วไฟฟ้าแอนโนดไปยังขั้วไฟฟ้าแคโทด ป้องกันการกลับมารวมตัวกันใหม่ ของคู่อิเล็กตรอนและโฮล หรือที่เรียกว่า Recombination และทำให้สารอินทรีย์เกิดการย่อยสลายได้ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงทำการแปรผันความต่างศักย์ไฟฟ้า และมีสภาวะการทดลองเป็นดังตารางที่ 3.13

ตารางที่ 3.13 สภาวะการทดลองหาค่าซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสที่จ่าย ความต่างศักย์ต่างกัน

11010	N/TINITIO/TINIT@			
สารอิเล็กโทรไลต์	ความต่างศั <mark>ก</mark> ย์	ปริมาณน้ำ	ความเข้มข้นซีโอ	ระยะเวลา
(โมลาร์)	(โวล <mark>ต์)</mark>	ตัวอย่าง	ดี	ในการวัดซีโอดี
		( <mark>ມີຄ</mark> ลิลิตร)	(มิล <mark>ลิกรั</mark> มต่อลิตร)	(นาที)
	0.5			
0.1	1.0	3	100	5
	1.5			

<u>หมายเหตุ</u> ใช้แกรไฟต์เป็นขั้วไฟฟ้าร่วม

#### 2) วัดค่าซีโอดีด้วยเครื่องโพเทนซิโอสแตท (Potentiostat)

จากการทดลองในข้างต้น จะเห็นได้ว่า กระแสของการวัดค่าซีโอดีที่

ความเข้มข้นเดียวกันในแต่ละซ้ำที่ทำการตรวจวัดนั้นไม่มีค่าใกล้เคียงกัน และเพื่อตรวจสอบดูว่าผลจาก การวัดที่ได้ไม่ได้เกิดจากการใช้การเครื่องมือที่สร้างขึ้นเอง จึงทดลองใช้เครื่องโพเทนซิโอสแตทในการวัด ค่ากระแสจากกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส โดยทำการวัดความเข้มข้นซีโอดีของกลูโคส 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเข้มข้นของสารอิเล็กโทรไลต์ที่ใช้คือ Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 0.1 โมลาร์ จ่ายความต่างศักย์ คงที่ 0.5 โวลต์ ใช้ปริมาตรน้ำ 3 มิลลิลิตร ใช้ระยะเวลาในการหาค่าซีโอดีต่างกัน สภาวะการทดลองเป็น ดังตารางที่ 3.14 ตารางที่ 3.14 สภาวะการทดลองหาค่าซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสที่ระยะเวลา ต่างกัน

สารอิเล็กโทรไลต์ (โมลาร์)	ความต่างศักย์ (โวลต์)	ปริมาณน้ำตัวอย่าง (มิลลิลิตร)	ความเข้มข้นซีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ระยะเวลา ในการวัดซีโอดี (นาที)
0.1	0.5	2	50	3
0.1	0.5	5	50	5

<u>หมายเหตุ</u> ใช้แกรไฟต์เป็นขั้วไฟฟ้าร่วม

#### 3.2.4.3 ศึกษาการตอบสนองต่อแสงของตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ ด้วยกระบวนการสปัตเตอริง

ทำการศึกษาการตอบสนองต่อแสง อาศัยหลักการของเซลล์ไฟฟ้าเคมี ประกอบด้วยเซลล์ไฟฟ้า 3 ขั้ว โดยมีซิงค์ออกไซด์ขนาด 1x 5 ตารางเซนติเมตร พื้นที่ใช้งานจริง 1x1 ตารางเซนติเมตร พื้นที่ 1x3 ตารางเซนติเมตร ใช้แคปตอนเทปติดป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปฏิกิริยา และพื้นที่ 1x1 ตารางเซนติเมตร ที่เหลือ ต่อเข้ากับสายไฟเป็นขั้วไฟฟ้าใช้งาน (Working electrode) แพลทินัม (Pt) เป็นขั้วไฟฟ้าร่วม (Counter electrode) และ Ag/AgCl เป็นขั้วไฟฟ้าอ้างอิง (Reference electrode) ทำการจุ่มขั้วไฟฟ้ารั่ว 3 ลงในสารละลายโซเดียมซัลเฟต (Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ ปริมาณ 3 มิลลิลิตร และต่อขั้วไฟฟ้าเข้ากับเครื่องมัลติมิเตอร์รุ่น keysight 34465a (สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน) เครื่องมือแสดงดังรูปที่ 3.20 เพื่อวัดกระแส และจ่ายความต่างศักย์คงที่ 0.2 โวลต์ จากเครื่องจ่ายความต่างศักย์เครื่องเดิมที่สร้างขึ้น ฉายแสงจากหลอดยูวี (UV-LED) ของบริษัท LedEngin Inc ขนาด 10 วัตต์ ความยาวคลื่น 365 นาโนเมตร ไปยังตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ โดยทำ การปิด-เปิดไฟสลับกันรอบละประมาณ 20 วินาที เก็บข้อมูล 1) การตอบสนองต่อแสงของ ตัวเร่งปฏิกิริยาก่อนติดพัดลมระบายอากาศของหลอดไฟ 2) การตอบสนองต่อแสงของตัวเร่งปฏิกิริยาเมื่อเปิดไฟตลอด ข่วงการทดลอง



รูปที่ 3.20 เครื่องมัลติมิเตอร์รุ่น keysight 34465a

3.2.4.4 ทำการตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำและความเสถียรของวิธีการหา ค่าซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสโดยใช้ซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการ สปัตเตอริงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

นำกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสมาประยุกต์ใช้ในการหาค่าซีโอดีโดยทำการ ตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำและความเสถียรของวิธีการ มีขั้นตอนการศึกษาดังนี้

#### 1) ทดสอบความเสถียรของซิงค์ออกไซด์โดยการวัดซ้ำของ สารละลายอิเล็กโตรไลต์ด้วยเครื่องโพเทนชิโอสแตท (Potentiostat)

นำตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้วัดค่าซีโอดีด้วย กระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส (COD<sub>PEC</sub>) โดยใช้ซิงค์ออกไซด์เป็นขั้วไฟฟ้าใช้งาน (Working Electrode) ใช้แพลทินัมเป็นขั้วไฟฟ้าร่วม (Counter electrode) และใช้ขั้วไฟฟ้าอิเล็กโทรดแบบ ซิลเวอร์/ซิลเวอร์คลอไรด์ (Ag/AgCl) เป็นขั้วไฟฟ้าอ้างอิง ขั้วไฟฟ้าทั้งสามต่อเข้ากับเครื่อง โพเทนซิโอสแตท (F9, SUT) เพื่อวัดกระแสที่เกิดขึ้นเมื่อสารละลายถูกออกซิไดซ์บนพื้นผิวของซิงค์ออก ไซด์ ใช้แหล่งกำเนิดแสงจากหลอดยูวีแอลอีดี (UV LED) ขนาด 10 วัตต์ ความยาวคลื่น 365 นาโนเมตร ทำ การวิเคราะห์เป็นจำนวน 5 ซ้ำ

#### การวัดซีโอดีด้วยเครื่องมัลติมิเตอร์ (multimeter)

นำตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้วัดค่าซีโอดีด้วย กระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส (COD<sub>PEC</sub>) โดยใช้ซิงค์ออกไซด์เป็นขั้วไฟฟ้าใช้งาน (Working Electrode) ใช้แกรไฟต์เป็นขั้วไฟฟ้าร่วม (Counter electrode) และใช้ขั้วไฟฟ้าอิเล็กโทรดแบบ ซิลเวอร์/ซิลเวอร์คลอไรด์ (Ag/AgCl) เป็นขั้วไฟฟ้าอ้างอิง ต่อเข้ากับเครื่องมัลติมิเตอร์เพื่อวัดกระแสที่ เกิดขึ้นเมื่อสารละลายถูกออกซิไดซ์บนพื้นผิวซิงค์ออกไซด์ ทำการวัดซีโอดีโดยไม่รอจนกระทั่ง สารอินทรีย์ถูกออกไซด์จนหมดหรือการตอบสนองด้วยกระแสของการวัดน้ำตัวอย่างที่ไม่มีสารอิทรีย์ไม่ต้อง ลดลงจนบรรจบกับการตอบสนองด้วยกระแสของการวัดน้ำตัวอย่างที่ไม่มีสารอินทรีย์ (Blank) ใช้ แหล่งกำเนิดแสงจากหลอดยูวีแอลอีดี (UV LED) ขนาด 10 วัตต์ ความยาวคลื่น 365 นาโนเมตร ลักษณะ การทดลองดังรูปที่ 3.21



รูปที่ 3.21 ลักษณะการทดลองการวัดซีโอดีโดยใช้เซลล์ไฟฟ้า 3 ขั้วต่อเข้ากับเครื่องมัลติมิเตอร์

2.1) ทดลองเบื้องต้นในการวัดซีโอดีด้วยเครื่องมัลติมิเตอร์

ทำการทุดลองเบื้องต้นในการวัดซีโอดีด้วยเครื่อง

มัลติมิเตอร์ โดยทำการวิเคราะห์หาค่าซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส (COD<sub>PEC</sub>) ของสาร มาตรฐานซีโอดีของกลูโคสที่ความเข้มข้นต่างกัน คือที่ 10 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร จ่ายความต่างศักย์ที่ ต่างกัน คือ 0.1 และ 0.2 โวลต์ <mark>และใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ที่ทำการ</mark>สปัตเตอริงที่ระยะเวลาต่างกัน คือ 60 นาที 120 นาที และ 240 น<mark>าที สภาวะการท<sub>ุ</sub>ดลองดังตารางที่</mark> 3.15



ตารางที่ 3.15 สภาวะการทดลองการวัดซีโอดีในเบื้องต้นโดยใช้ซิงค์ออกไซด์ที่ผ่านการสปัตเตอริงเป็น ตัวเร่งปฏิกิริยา

เวลาสปัตเตอริง (นาที)	สาร อิเล็กโทรไลต์ (โมลาร์)	ความต่างศักย์ (โวลต์)	ปริมาณน้ำตัวอย่าง (มิลลิลิตร)	ความเข้มข้นซีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ระยะเวลา ในการวัดซีโอดี (นาที)															
		0.1		10																
60		0.1		50																
00		0.2		10																
		0.2		50																
		.1 0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		10	
120	0.1								3	50	Б									
120	0.1								0.2	0.2		10								
											0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
			HH	10																
240		0.1		50																
		0.2		10																
		0.2		50																

<u>หมายเหตุ</u> ใช้แกรไฟต์เป็นขั้วไฟฟ้าร่วม

## 2.2) เปรียบเทียบการใช้ขั้วไฟฟ้าร่วมต่างชนิดกัน

ทำการเปรียบเทียบ<mark>ก</mark>ารใช้ขั้วไฟฟ้าร่วม (Counter

electrode) ต่างชนิดกัน ได้แก่ แกรไฟต์ (graphite) และแพลทินัม (Pt) ใช้ซิงค์ออกไซด์ที่ผ่าน การสปัตเตอริงเป็นเวลา 120 นาที พื้นที่ทำปฏิกิริยาขนาด 1x1 ตารางเซนติเมตร เป็นขั้วไฟฟ้าใช้งาน ทำโดยการวัดการตอบสนองของกระแสไฟฟ้าในสารละลายโซเดียมซัลเฟต (Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) 0.1 โมลาร์ ปริมาณ 3 มิลลิลิตร จ่ายความต่างศักย์ไฟฟ้า 0.2 โวลต์ เป็นเวลา 5 นาที ทำการเป็นจำนวน 5 ซ้ำ เพื่อ ตรวจสอบดูว่าขั้วไฟฟ้าร่วมชนิดใดจะเป็นผู้ช่วยที่ดีในการส่งผ่านอิเล็กตรอนหรือกระแสไปยังขั้วไฟฟ้าใช้ งานได้ดีกว่า โดยมีสภาวะการทดลองแสดงดังตารางที่ 3.16

## ยาลัยเทคโนโลยีสุร

ตารางที่ 3.16 สภาวะการทดลองการใช้ขั้วฟ้าร่วมต่างชนิด

ชนิดของขั้วฟ้าร่วม	สารอิเล็กโทรไลต์ (โมลาร์)	ความต่างศักย์ (โวลต์)	ปริมาณน้ำตัวอย่าง (มิลลิลิตร)	ระยะเวลา ในการวัด (นาที)
แกรไฟต์	0.1	0.0	2	F
แพลทินัม	0.1	0.2	5	5

#### ตรวจสอบความถูกต้องแม่นย่ำและความเสถียรของวิธีการหาค่า ซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสโดยใช้ซิงค์ออกไซด์ที่สปัตเตอริง 120 นาที เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

#### 3.1) ทำการแปรผันความเข้มข้นของซีโอดี

ทำการวิเคราะห์หาค่าซีโอดีด้วยกระบวนการ โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส (COD<sub>PEC</sub>) ของสารมาตรฐานซีโอดีที่ความเข้มข้นที่ต่าง ๆ กัน คือ ซีโอดีจาก สารละลายมาตรฐานกลูโคส (D-glucose) ที่ความเข้มข้น 0- 500 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ละความเข้มข้นของ ซีโอดี กลูโคสจะถูกผสมเข้ากับสารอิเล็กโทรไลต์โซเดียมซัลเฟต (Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) 0.1 โมลาร์ ใช้น้ำตัวอย่าง ปริมาณ 3 มิลลิลิตร และจ่ายความต่างศักย์คงที่ 0.2 โวลต์ เป็นเวลา 5 นาที แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 ทำการวัดซีโอดีจากความเข้มข้นต่ำไปสูง ชุดที่ 2 วัดซีโอดีจากความเข้มข้นสูงไปต่ำ โดยใช้ ตัวเร่งปฏิกิริยาตัวเดียวสำหรับการวิเคราะห์แต่ละชุด เป็นการตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำ เทียบกับ ค่าซีโอดีตามทฤษฎี (COD<sub>Theory</sub>) สภาวะการทดลองแสดงดังตารางที่ 3.17

ตารางที่ 3.17 สภาวะการทดลองหาค่าซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสที่ซีโอดี ความเข้มข้นต่าง ๆ

ชุดที่	สารอิเล็กโทรไลต์ (โมลาร์)	ความต่างศักย์ (โวลต์)	<mark>ปริ</mark> มาณน้ำตัว <mark>อย่า</mark> ง (มิลลิลิตร)	ความเข้มข้นซีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ระยะเวลา ในการวัดซีโอดี (นาที)
1	0.1	0.2		5 10 50 100 200 500	5
2	0.1	150,2818	<b>รัยเท</b> ล์โนโล	500 200 100 50 10 5	5

<u>หมายเหตุ</u> ใช้แพลทินัมเป็นขั้วไฟฟ้าร่วม

#### 3.2) ทำการวัดซ้ำที่ความเข้มข้นของซีโอดีเดียวกัน

นำซิงค์ออกไซด์ที่ทำการสังเคราะห์ด้วยวิธีการสปัตเตอริง เป็นเวลา 120 นาที บนโพลิไอมายด์ฟิล์มที่เคลือบด้วยทองแดง พื้นที่ทำปฏิกิริยาขนาด 1x1 ตาราง เซนติเมตร มาทำการวัดซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส COD<sub>PEC</sub> ของกลูโคสที่ความ เข้มข้นเดียวกัน คือ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตรน้ำตัวอย่าง 3 มิลลิลิตร ทำการวิเคราะห์เป็นจำนวน 4 ซ้ำ (n=4) โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาตัวเดียวกัน จ่ายความต่างศักย์ 0.2 โวลต์ แล้วทำการวัดซีโอดี เป็นเวลา 5 นาที เพื่อเป็นการตรวจสอบความเสถียรของวิธีการ เทียบกับค่าซีโอดีตามทฤษฎี (COD<sub>Theory</sub>)

3.3) ศึกษาผลของการใช้ซ้ำของตัวเร่งปฏิริยาซิงค์ออกไซด์

นำตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ที่ทำการสังเคราะห์ด้วย วิธีการสปัตเตอริงเป็นเวลา 120 นาที บนโพลิไอมายด์ฟิล์มที่เคลือบด้วยทองแดง พื้นที่ทำปฏิกิริยาขนาด 1x1 ตารางเซนติเมตร มาทำการวัดซีโอดีของกลูโคสความเข้มข้นตั้งแต่ 0-500 มิลลิกรัมต่อลิตร และซีโอดี ของโพแทสเซียมไฮโดรเจนพลาเลต (KHP) ที่ความเข้มข้น 0-150 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตรน้ำตัวอย่าง 3 มิลลิลิตร ทุก ๆ ความเข้มข้นทำการวิเคราะห์เป็นจำนวน 3 ซ้ำ (n=3) เพื่อศึกษาผลของจำนวนรอบ การใช้ซ้ำของตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ที่มีต่อการใช้วัดซีโอดีในกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส สภาวะการทดลองเป็นดังตารางที่ 3.18

สารอิเล็กโทร ไลต์ (โมลาร์)	ความต่างศักย์ (โวลต์)	ปริมาณ น้ำตัวอย่าง (มิลลิลิตร)	<mark>สา</mark> รซีโอดีทาง ทฤษฎี	ความเข้มข้นซีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ระยะเวลา ในการวัดซีโอดี (นาที)
0.1	0.2	3	กลูโค <mark>ส</mark> KHP	100	5

ิตารางที่ 3.18 สภาวะการทดลองหาค่าซีโอดีของสา<mark>ร</mark>ซีโอดีทางทฤษฎีต่างชนิดกัน

<u>หมายเหตุ</u> ใช้แพลทินัมเป็นขั้วไฟฟ้าร่วม

#### สึกษาการตอบสนองของซิงค์ออกไซด์ที่ความต่างศักย์ต่าง ๆ

์ศึก<mark>ษาการตอบสนองของซิงค์อ</mark>อกไ<mark>ซด์ที่</mark>ความต่างศักย์ต่าง ๆ โดยการ

แปรผันความต่างศักย์ตั้งแต่ 0.1 โวลต์ จนถึง 1.0 โวลต์ ให้แก่ตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ในการวัด สารละลายอิเล็กโทรไลต์โซเดียมซัลเฟต 0.1 โมลาร์ สลับกับสารละลายอิเล็กโทรไลต์โซเดียมซัลเฟต 0.1 โมลาร์ที่มีสารอินทรีย์ที่ให้ค่าซีโอดีในเชิงทฤษฎี คือ โพแทสเซียมไฮโดรเจนพลาเลต (KHP) ที่มีความ เข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อลิตร เพื่อตรวจสอบดูว่าที่การจ่ายความต่างศักย์ใดเหมาะสมสำหรับการวัดซีโอดี สภาวะการทดลองแสดงดังตารางที่ 3.19

69

สารละลาย	ความต่างศักย์ (โวลต์)	ปริมาณ น้ำตัวอย่าง (มิลลิลิตร)	ระยะเวลา ในการวัด (นาที)
Na2SO4 0.1 โมลาร์	0.1		
KHP 50 มิลลิกรัมต่อลิตร	0.1		
Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 0.1 โมลาร์	0.2		
KHP 50 มิลลิกรัมต่อลิตร	0.2		
Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 0.1 โมลาร์	0.2		
KHP 50 มิลลิกรัมต่อลิตร	0.5		
Na <sub>2</sub> SO4 0.1 โมลาร์			
KHP 50 มิลลิกรัมต่อลิตร	0.4		
Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 0.1 โมลาร์	0.5		
KHP 50 มิลลิกรัมต่อลิตร	0.5	3	5
Na2SO4 0.1 โมลาร์	06		C.
KHP 50 มิลลิกรัมต่อลิตร	0.0		
Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 0.1 โมลาร์	0.7		
KHP 50 มิลลิกรัมต่อลิตร	0.1		
Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 0.1 โมลาร์			
KHP 50 มิลลิกรัมต่อลิตร	0.8		
Na2SO4 0.1 โมลาร์			
KHP 50 มิลลิกรัมต่อลิตร	0.7		
Na2SO4 0.1 โมลาร์			
KHP 50 มิลลิกรัมต่อลิตร	1.0	10	

ตารางที่ 3.19 สภาวะการศึกษาการตอบสนองของซิงค์ออกไซด์ที่ความต่างศักย์ต่าง ๆ

<u>หมายเหต</u>ู ใช้แพลทินัมเป็นขั้วไฟฟ้าร่วม

# 5) การเคลื่อนย้ายตำแหน่งอุปกรณ์ในการวัดซีโอดี

ทำการศึกษาผลของการเคลื่อนย้ายตำแหน่งอุปกรณ์ในการวัด ซีโอดี โดยทำการวัดการตอบสนองของสารละลายอิเล็กโทรไลต์โซเดียมซัลเฟต 0.1 โมลาร์ และ สารละลายอิเล็กโทรไลต์โซเดียมซัลเฟต 0.1 โมลาร์ที่มีสารอินทรีย์ที่ให้ค่าซีโอดีในเชิงทฤษฎี คือกลูโคสที่ ความเข้มข้นตั้งแต่ 0-200 มิลลิกรัมต่อลิตร ภายใต้แสงยูวีความยาวคลื่น 365 นาโนเมตร และจ่ายความ ต่างศักย์ที่ 0.2 และ 0.5 โวลต์ ไปยังตัวเร่งปฏิริยาซิงค์ออกไซด์ที่ผ่านการสปัตเตอริงเป็นเวลา 120 นาที ขนาด 1x1 ตารางเซนติเมตร โดยที่ทำการเพิ่มปริมาตรน้ำตัวอย่างครั้งละ 0.5 มิลลิลิตร ในการวัดแต่ละ รอบ ๆ ละ 3 นาที โดยที่ไม่มีการเคลื่อนย้ายตำแหน่งอุปกรณ์ในการวัด เพื่อตรวจสอบว่าการเปลี่ยนที่ ของตำแหน่งการใช้ปากคีบคีบที่ขั้วไฟฟ้าหรือการขยับตำแหน่งการวางขั้วไฟฟ้าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการ วัดซีโอดี สภาวะการทดลองดังตารางที่ 3.20

สารละลาย	ความต่างศักย์ (โวลต์)	ปริมาณ น้ำตัวอย่าง (มิลลิลิตร)	ระยะเวลา ในการวัด (นาที)
		2.0	
		2.5	
Na. 50, 01 โมลาร์		3.0	
Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 0.1 โมลาร้	0.2	3.5	
		4.0	
		4.5	
		5.0	
กลูเศส 0 มสสการมดอสตร		2.0	
กลูเคส 5 มลลกรมตอลตร		2.5	
กลูโคส 10 มลลกรมตอลตร		3.0	
กลูโคส 20 มิลลิกรัมต่อลิตร	0.2	3.5	
กลูโคส 50 มิลลิกรัมต่อลิตร	ΠΡη.	4.0	3
กลูโคส 100 มิลลิกรัมต่อลิตร		4.5	
กลูโคส 150 มิลลิกรัมต่อลิตร 🛛 🖊		5.0	
กลูโคส 200 มิลลิกรัมต่อลิตร 🛛 🦯		5.5	
กลูโคส 0 มิลลิกรัมต่อลิตร 🛛 🦰		2.0	
กลูโคส 5 มิลลิกรัมต่อลิตร 🗾 丨		2.5	
กลูโคส 10 มิลลิกรัมต่อลิตร		3.0	
กลูโคส 20 มิลลิกรัมต่อลิตร		3.5	
กลูโคส 50 มิลลิกรัมต่อลิตร	0.5	4.0	
กลูโคส 100 มิลลิกรัมต่อลิตร		4.5	
กลูโคส 150 มิลลิกรัมต่อลิตร 💜 🕙	ไล้ยเทคโนโล	5.0	
กลโคส 200 มิลลิกรัมต่อลิตร		5.5	

ตารางที่ 3.20 สภาวะการทดลองเพื่อตรวจสอบปัจจัยการเคลื่อนย้ายตำแหน่งอุปกรณ์ในการวัดซีโอดี

 ตรวจสอบความถูกต้องแม่นย่ำและความเสถียรของวิธีการหาค่า ซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสโดยใช้ซิงค์ออกไซด์ที่สปัตเตอริง 480 นาที เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

#### 6.1) ทำการแปรผันความเข้มข้นของซีโอดี

นำตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ที่ทำการสังเคราะห์ด้วย

วิธีการสปัตเตอริงเป็นเวลา 480 นาที ขนาด 0.5x0.5 ตารางเซนติเมตร บนแคปตอนเทปที่เคลือบด้วย ทองแดง มาทำการวิเคราะห์หาค่าซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส (COD<sub>PEC</sub>) ของสาร มาตรฐานซีโอดีที่ความเข้มข้นที่ต่าง ๆ กัน คือซีโอดีของสารละลาย KHP ความเข้มข้นซีโอดีตั้งแต่ 0-500 มิลลิกรัมต่อลิตร (ทุกความเข้มข้นของซีโอดีใช้ชิงค์ออกไซด์แผ่นเดิมในการวัด) ความเข้มข้นของ สารอิเล็กโทรไลต์โซเดียมซัลเฟต 0.1 โมลาร์ ปริมาตรน้ำ 3 มิลลิลิตร ระยะเวลาที่ใช้ในการหาค่าซีโอดี 1 นาที จ่ายความต่างศักย์ที่ 0.5 โวลต์ สภาวะการทดลองแสดงดังตารางที่ 3.21

ตารางที่ 3.21 สภาวะการทดลองหาค่าซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสที่ซีโอดี คาามเข้มข้มต่าง ๆ

สารอิเล็กโทรไลต์ (โมลาร์)	ความต่างศักย์ (โวลต์)	ปริมาณน้ำตัวอย่าง (มิลลิลิตร)	ความเข้มข้นซีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ระยะเวลา ในการวัดซีโอดี (นาที)
			10	
			20	
0.1 0.5	0 E	3	50	. 1
	0.5		100	L
			200	
			500	

<u>หมายเหต</u>ุ ใช้แพลทินัมเป็นขั้วไฟฟ้าร่วม

### 6.2) ทำการวัดซ้ำที่คว<mark>ามเ</mark>ข้มข้นของซีโอดีเดียวกัน

นำซิงค์ออกไซด์ที่<mark>ทำกา</mark>รสังเคราะห์ด้วยวิธีการสปัตเตอริง

เป็นเวลา 120 นาที บนโพลิไอมา<mark>ย</mark>ด์ฟิล์มที่เคลือบด้วยทองแดง พื้นที่ทำปฏิกิริยาขนาด 1x1 ตาราง เซนติเมตร มาทำการวัดซีโอดี<mark>ด้วย</mark>กร<mark>ะบวนการโฟโตอิ</mark>เล็กโตรคะตะไ<mark>ลซิ</mark>ส COD<sub>PEC</sub> ของกลูโคสที่ความ เข้มข้นเดียวกัน คือ 100 มิลลิ<mark>กรัม</mark>ต่อลิตร ปริมาตรน้ำตัวอย่าง 3 มิลลิลิตร ทำการวิเคราะห์เป็นจำนวน 5 ซ้ำ (n=5) โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิร<mark>ิยาตัวเ</mark>ดียวกัน จ่ายความต่างศักย์ 0.5 โวลต์ แล้วทำการวัดซีโอดี เป็นเวลา 1 นาที เพื่อเป็นการตรวจสอบคว<mark>ามเสถียรของวิธีการ เทียบกับค่าซีโอด</mark>ีตามทฤษฎี (COD<sub>Theory</sub>)

7) ตรวจสอบความเสถียรของตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ ตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ที่ผ่านการใช้วัดซีโอดีด้วยกระบวนการโฟ โตอิเล็กโตรคะตะไลซิสแล้วจะนำไปถ่ายภาพ FESEM เพื่อดูลักษณะสัณฐานวิทยา และใช้ FESEM โหมด EDS เพื่อดูองค์ประกอบของธาตุที่มีอยู่บนพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยนำมา เปรียบเทียบกับข้อมูลภาพถ่ายและ EDS สเปกตรัม ของซิงค์ออกไซด์ที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน จากนั้น ทำ การเก็บตัวอย่างน้ำหลังการวัดซีโอดีไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง ICP-MS ว่ามีธาตุองค์ประกอบของซิงค์หลุด ้ลอกในน้ำตัวอย่างหรือไม่ เพื่อตรวจสอบความเสถียรของซิงค์ออกไซด์หลังการวัดซีโอดีและเป็นข้อมูลใน การพิจารณาการนำกลับมาใช้ซ้ำ

### บทที่ 4 ผลการวิจัย

กระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส คือการประยุกต์กระบวนการโฟโตคะตะไลซิสร่วมกับ เซลล์ไฟฟ้า 3 ขั้ว โดยจะต้องมีการกระตุ้นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยพลังงานแสง เพื่อให้ตัวเร่งปฏิกิริยาเกิด อิเล็กตรอนและที่ว่างของอิเล็กตรอน ในที่สุดจะเกิดเป็นเรดิคอล ที่มีความสามารถในการออกซิไดซ์ สารอินทรีย์ได้ ซึ่งในงานวิจัยนี้แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ (1) การสังเคราะห์ไทเทเนียมได ออกไซส์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการหาค่าซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส และ (2) การ ทดลองการค่าซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส โดยตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมได ออกไซด์นั้นจะสังเคราะห์ด้วยกระบวนการแอโนไดเซซันแบบพัลส์ แล้วจะนำไปวิเคราะห์คุณลักษณะ เบื้องต้น เพื่อหาสภาวะการสังเคราะห์ที่ดีที่สุด แล้วนำไปใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการทดลองการค่าซีโอ ดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส

#### 4.1 ไทเทเนียมไดออกไซด์

4.1.1 การสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยกระบวนการแอโนไดเซซันแบบพัลส์เป็น ตัวเร่งปฏิกิริยา

#### 4.1.1.1 การวิเคราะห์สัณ<mark>ฐาน</mark>วิทยา

การทดลองเบื้องต้นของการสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วย กระบวนการแอโนไดซ์ เริ่มต้นด้วยการใช้แผ่นไทเทเนียมขนาด 4 ตารางเซนติเมตร (กว้าง 1 เซนติเมตร ยาว 4 เซนติเมตร) นำไปล้างด้วยเครื่องอัลตราโซนิค 3 ขั้นตอน ด้วยอะซีโตน ทู-โพรพานอล และน้ำ ปราศจากไอออน ขั้นตอนละ 5 นาที ตามลำดับ จากนั้นนำไปเป่าให้แห้งด้วยก๊าซไนโตรเจน ก่อนจะ นำไปใช้ในกระบวนการแอโนไดเซซัน

กระบวนการแอโนโดเซซันนั้น ใช้แผ่นไทเทเนียมที่เตรียมได้จากข้างต้นมา เป็นขั้วไฟฟ้าใช้งาน ต่อเข้ากับขั้วบวกของแหล่งจ่ายไฟฟ้า และใช้แพลทินัมเป็นขั้วไฟฟ้าร่วมต่อเข้ากับขั้ว ลบของแหล่งจ่ายไฟฟ้า จุ่มขั้วไฟฟ้าทั้งสองในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ 0.30 โมลาร์ ของแอมโมเนียม ฟลูออไรด์ ผสมด้วยกลีเซอรอลและน้ำในอัตราส่วน 60 : 40 จ่ายความต่างศักย์ 20 โวลต์ (แบบต่อเนื่อง) เป็นเวลา 3 ชั่วโมง จากนั้นนำไปวิเคราะห์ลักษณะสัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ ส่องกราด (FE-SEM) พบว่าลักษณะพื้นผิวของไทเทเนียมไดออกไซด์มีลักษณะเป็นรูปท่อขนาดนาโน เมตร แสดงดังรูป 4.1



รูปที่ 4.1 ภาพถ่าย FESEM กำลังขยาย 50,000 เท่าของแผ่น TiO<sub>2</sub> ที่ผ่านการแอโนไดซ์ ที่ความต่างศักย์ 20 โวลต์<mark>(แบบต่อเนื่อง) เ</mark>ป็นระยะเวลา 3 ชั่วโมง

ขั้นแรกได้ทำการทดลองโดยแปรเปลี่ยนความต่างศักย์ด้านสูงและต่ำ เพื่อหา สภาวะการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสม ซึ่งยังคงใช้สารละลายอิเล็กโทรไลต์ 0.30 โมลาร์ ของ แอมโมเนียมฟลูออไรด์ ผสมด้วยกลีเซอรอลและน้ำในอัตราส่วน 60 : 40 แผ่นไทเทเนียมขนาด 4 ตารางเซนติเมตร (กว้าง 1 เซนติเมตร ยาว 4 เซนติเมตร) รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการสังเคราะห์ ทั้งหมด 3 ชั่วโมง ดังเดิม ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้ทั้งหมด 4 สภาวะ ดังตารางที่ 4.1 และผลการ ทดลองการวิเคราะห์ลักษณะสัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (FESEM) แสดงดังตารางที่ 4.2 – 4.4

ลำดับ	Lable	สภาวะการสังเคราะห์
	A <sub>1</sub>	20 โวลต์ 10 นาที/0 โวลต์ 5 วินาที
สภาวะการทดลองที่ 1	A <sub>2</sub>	20 โวลต์ 5 นาที/0 โวลต์ 5 วินาที
	A <sub>3</sub>	20 โวลต์ 1 นาที/0 โวลต์ 5 วินาที
	B <sub>1</sub>	20 โวลต์ 10 นาที/0 โวลต์ 20 วินาที
สภาวะการทดลองที่ 2	B <sub>2</sub>	20 โวลต์ 5 นาที/0 โวลต์ 20 วินาที
	B <sub>3</sub>	20 โวลต์ 1 นาที/0 โวลต์ 20 วินาที
	C <sub>1</sub>	20 โวลต์ 10 นาที/-5 โวลต์ 5 วินาที
สภาวะการทดลองที่ 3	C <sub>2</sub>	20 โวลต์ 5 นาที/-5 โวลต์ 5 วินาที
	C <sub>3</sub>	20 โวลต์ 1 นาที/-5 โวลต์ 5 วินาที
	$D_1$	20 โวลต์ 10 นาที/-5 โวลต์ 20 วินาที
สภาวะการทดลองที่ 4	D <sub>2</sub>	20 โวลต์ 5 นาที/-5 โวลต์ 20 วินาที
	D <sub>3</sub>	20 โวลต์ 1 นาที/-5 โวลต์ 20 วินาที

ตารางที่ 4.1 สภาวะการทดลองที่จะเปรียบเทียบลักษณะสัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แบบส่องกราด (FE-SEM)

จากตารางที<mark>่ 4.1</mark> ข้อแตกต่างที่ใช<mark>้ในก</mark>ารเปรียบเทียบของแต่ละสภาวะการ

ทดลองคือ ความถี่ของระยะเวลาที่ใช้ในพัลส์ด้านสูง (20 โวล<mark>ต์ 1</mark>0 นาที 5 นาที และ1 นาที) โดยสิ่งที่ เหมือนกัน คือศักย์ไฟฟ้าและระยะเวลาที่ใช้ในพัลส์ด้านต่ำ



ตารางที่ 4.2 ลักษณะสัณฐานของไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ทำการสังเคราะห์ด้วยกระบวนการ แอโนไดเซซันแบบพัลส์ของสภาวะการทดลองที่ 1

Labla	กำลังขยายเครื่อง FESEM	
Lable	15,000 เท่า	50,000 เท่า
A <sub>1</sub> 20 V 10 min / 0 V 5 sec 3 hr	2.15.000 0.047 02.1 0.047 02.1 0.04400 0.4440 0.0	1.59,000 1.000 ETE <u>3/31/504</u>
A <sub>2</sub> 20 V 5 min / 0 V 5 sec 3 hr	15.50 2.07 km <sup>2</sup> 2.07 cm <sup>2</sup> 1.07 cm <sup>2</sup> 2.12 km <sup>2</sup>	101 M 201 M
A <sub>3</sub> 20 V 1 min / 0 V 5 sec 3 hr		

Goulling

ตารางที่ 4.3 ลักษณะสัณฐานของไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ทำการสังเคราะห์ด้วยกระบวนการ แอโนไดเซซันแบบพัลส์ของสภาวะการทดลองที่ 2

Labla	กำลังขยายเค	ารื่อง FESEM
Lable	15,000 เท่า	50,000 เท่า
B <sub>1</sub> 20 V 10 min / 0 V 20 sec 3 hr	10.00 M 20.00 M	100 M 100 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2
B <sub>2</sub> 20 V 5 min / 0 V 20 sec 3 hr	2.15.000 <b>9.000 10.1 10.0 10.4 0.01 0.4 0.01 0.4 0.01 0.4 0.01 0.4 0.01 0.4 0.01 0.4 0.01 0.4 0.01 0.4 0.01 0.4 0.01 0.4 0.01 0.4 0.01 0.4 0.01 0.4 0.01 0.4 0.01 0.4 0.01 0.4 0.01</b>	1 50.00 2 12 1 20 12 12 10 4 - 70 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
B <sub>3</sub> 20 V 1 min / 0 V 20 sec 3 hr		

Goulling

ตารางที่ 4.4 ลักษณะสัณฐานของไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ทำการสังเคราะห์ด้วยกระบวนการ แอโนไดเซซันแบบพัลส์ของสภาวะการทดลองที่ 3

Labla	กำลังขยายเครื่อง FESEM	
Lable	15,000 เท่า	50,000 เท่า
C <sub>1</sub> 20 V 10 min / -5 V 5 sec 3 hr		x 50,000 b. 047 gtt 100m Tar 3/33/2014
C <sub>2</sub> 20 V 10 min / -5 V 5 sec 3 hr		
C <sub>3</sub> 20 V 10 min / -5 V 5 sec 3 hr		

1991UHINIC

ตารางที่ 4.5 ลักษณะสัณฐานของไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ทำการสังเคราะห์ด้วยกระบวนการ แอโนไดเซซันแบบพัลส์ของสภาวะการทดลองที่ 4

กำลังขยายเครื่อง FESEM		ารื่อง FESEM
Lable	15,000 เท่า	50,000 เท่า
D <sub>1</sub> 20 V 10 min / -5 V 20 sec 3 hr		
D <sub>2</sub> 20 V 10 min / -5 V 20 sec 3 hr		
D <sub>3</sub> 20 V 10 min / -5 V 20 sec 3 hr		L 59,000 E. DEF BER 20 4 1500 1014120

จากตารางที่ 4.2 เมื่อนำไปวิเคราะห์ลักษณะสัณฐานวิทยาด้วยกล้อง FESEM

ที่กำลังขยาย 15,000 เท่า และ 50,000 เท่า พบว่าทุกสภาวะลักษณะของออกไซด์ที่เกิดเป็นรูปท่อ - สภาวะ A<sub>1</sub> ที่กำลังขยาย 15,000 เท่า ความสูงของท่อไม่แตกต่างกัน

มาก และที่กำลังขยาย 40,000 เท่า ลักษณะออกไซด์ที่เกิดมีรูปร่างเป็นของท่อ<sup>์</sup>ที่ชัดเจน ผนังท่อแยก ออกจากกัน และส่วนมากจะเกิดออกไซด์ของท่อที่ซ้อนทับกันอยู่

- สภาวะ A<sub>2</sub> ที่กำลังขยาย 15,000 เท่า พบว่าความสูงของท่อแตกต่าง

กันอย่างชัดเจน และที่กำลังขยาย 40,000 เท่า ลักษณะออกไซด์มีขนาดท่อที่แตกต่างกันหลายขนาด เกิดท่อออกไซด์ที่ซ้อนทับกัน และผนังท่อส่วนใหญ่เชื่อมติดกัน - สภาวะ A<sub>3</sub> ที่กำลังขยาย 15,000 เท่า ออกไซด์รูปท่อที่เกิดนั้น ส่วน ใหญ่มีความสูงสม่ำเสมอกัน และที่กำลังขยาย 40,000 เท่า ท่อที่มีผนังเชื่อมติดกัน มีทั้งผนังท่อที่ชัดเจน และผนังที่ขาดไม่เป็นท่อ และบางส่วนมีแผ่นออกไซด์เกิดซ้อนทับกันอยู่อย่างชัดเจน

จากตารางที่ 4.3 เมื่อนำไปวิเคราะห์ลักษณะสัณฐานวิทยาด้วยกล้อง FESEM ที่กำลังขยาย 15,000 เท่า และ 50,000 เท่า มีทั้งสภาวะที่เป็นออกไซด์รูปท่อและไม่เป็นรูปท่อ ดังนี้

- สภาวะ B1 ที่กำลังขยาย 15,000 เท่า ความสูงของออกไซด์รูปท่อ มี ทั้งส่วนที่สม่ำเสมอกัน และส่วนที่แตกต่างกันกันอย่างชัดเจน ที่กำลังขยาย 40,000 เท่า ลักษณะ ออกไซด์เป็นรูปท่อที่ค่อนข้างชัดเจน ท่อมีขนาดที่ใกล้เคียงกัน และมีออกไซด์ที่ซ้อนทับเพียงเล็กน้อย

- สภาวะ B<sub>2</sub> ที่กำลังขยาย 15,000 เท่า ความสูงของออกไซด์ที่เกิด มี ความสม่ำเสมอกันมาก แต่ที่กำลังขยาย 40,000 เท่า พบว่าท่อมีผนังที่เชื่อมติดกัน และบางส่วนของ ผนังท่อขาด รวมถึงมีออกไซด์เกิดซ้อนทับกันอย่

 สภาวะ B₃ ที่กำลังขยาย 15,000 เท่า ลักษณะออกไซด์ที่ได้เป็นรู พรุนขนาดเล็ก ที่เกิดซ้อนทับกันอยู่เป็นจำนวนมาก และที่กำลังขยาย 40,000 เท่า ออกไซด์ที่เกิดนั้น เป็นรูพรุนที่มีลักษณะเป็นรูปท่อ แต่เป็นท่อที่ยังไม่สมบูรณ์ ผนังท่อบางส่วนเชื่อมติดกัน และส่วนใหญ่ ผนังขาดไม่เป็นรูปท่อ

จากตารางที่ 4.4 <mark>เมื่อ</mark>นำไปวิเค<mark>ราะ</mark>ห์ลักษณะสัณฐานวิทยาด้วยกล้อง FESEM ที่กำลังขยาย 15,000 เท่า และ 50,000 เท่า แสดงลักษณะออกไซด์ที่เกิดดังนี้

- สภาวะ C<sub>1</sub> ที่กำลังขยาย 15,000 เท่า ท่อที่เกิดมีความสูงต่ำที่ แตกต่างกันอย่างชัดเจน เกาะกันเป็นกลุ่ม และที่กำลังขยาย 40,000 เท่า ท่อนั้นลู่เข้าหากัน เกาะกัน กลุ่ม ๆ แต่มีผนังท่อที่เกิดชัดเจน

 สภาวะ C₂ ที่กำลังขยาย 15,000 เท่า ท่อที่เกิดมีความหนาแน่นที่ สม่ำเสมอกัน แต่ความสูงของนั้นยังไม่เท่ากัน และที่กำลังขยาย 40,000 เท่า ท่อนั้นลู่เข้ากันน้อยลงเมื่อ
เทียบกับสภาวะ C₁ แต่ผนังท่อส่วนใหญ่ขาด และมีขนาดท่อที่แตกต่างกันหลายขนาด

สภาวะ C<sub>3</sub> ที่กำลังขยาย 15,000 เท่า ท่อที่เกิดนั้นแยกชั้นความสูง
ต่ำออกจากกันอย่างชัดเจน ท่อที่สูงขึ้นมากว่าชั้นแรก จะลู่เข้าหากัน เกาะกันเป็นกลุ่ม และที่กำลังขยาย
40,000 เท่า ท่อชั้นแรกบางส่วนมีลักษณะเป็นรูปท่อที่ชัดเจน บางส่วนยังเป็นท่อที่ไม่สมบูรณ์ ผนังของ
ท่อแยกออกจากกัน เช่นเดียวกันกับท่อที่สูงขึ้นมา

จากตารางที่ 4.5 เมื่อนำไปวิเคราะห์ลักษณะสัณฐานวิทยาด้วยกล้อง FESEM

ที่กำลังขยาย 15,000 เท่า และ 50,000 เท่า แสดงลักษณะที่เป็นออกไซด์ที่เกิดเป็นรูปท่อดังนี้ - สภาวะ D1 ที่กำลังขยาย 15,000 เท่า ท่อที่เกิดมีความสูงที่ไม่เท่ากัน

แต่ไม่แตกต่างกันมากเกินไป ความหนาแน่นที่เกิดนั้นสม่ำเสมอกัน กลุ่ม และที่กำลังขยาย 40,000 เท่า ลักษณะท่อมีผนังที่ชัดเจน ไม่เชื่อมติดกัน แต่บางส่วนก็มีผนังท่อที่ขาดเกิดขึ้นเช่นกัน

- สภาวะ D<sub>2</sub> ที่กำลังขยาย 15,000 เท่า ท่อนั้นมีการกระจายตัว และ ความสูงต่ำที่สม่ำเสมอกัน ที่กำลังขยาย 40,000 เท่า ท่อที่เกิดนั้นมีขนาดที่แตกต่างกัน แต่ไม่มีการเชื่อม ติดกันของผนังท่อเลย - สภาวะ D₃ ที่กำลังขยาย 15,000 เท่า ลักษณะออกไซด์ที่เกิดเป็นรู พรุน เกิดขึ้นทับซ้อนกันเป็นชั้น ๆ และที่กำลังขยาย 40,000 เท่า พบว่ารูพรุนที่เกิดมีลักษณะเป็นรูปท่อ เกิดซ้อนทับกันอยู่ แต่ยังเป็นท่อไม่สมบูรณ์ ผนังท่อขาด และมีขนาดท่อที่แตกต่างกัน

Lable	สภาวะการสังเคราะห์	ลักษณะท่อ	เส้นผ่าน ศูนย์กลางท่อ
A <sub>1</sub>	20 โวลต์ 10 นาที/0 โวลต์ 5 วินาที	รูปร่างชัดเจน มีขนาดแตกต่างกัน	35-100 nm
A <sub>2</sub>	20 โวลต์ 5 นาที/0 โวลต์ 5 วินาที	ผนังท่อเชื่อมติดกัน <mark>เกิ</mark> ดออกไซด์ซ้อนทับกัน	35-100 nm
A <sub>3</sub>	20 โวลต์ 1 นาที/0 โวลต์ 5 วินาที	รูปร่างซัดเจน ผ <mark>น</mark> ังท่อขาดและเชื่อมติดกัน	35-100 nm
B <sub>1</sub>	20 โวลต์ 10 นาที/0 โวลต์ 20 วินาที	รูป <mark>ร่าง</mark> ชัดเจน ท่อมีข <mark>นาด</mark> ใกล้เคียงกัน	40-100 nm
B <sub>2</sub>	20 โวลต์ 5 นาที/0 โว <mark>ล</mark> ต์ 20 วินาที	ผนังท่อเชื่อมติดกัน เกิดออกไซด์ซ <b>้อ</b> นทับกัน	40-100 nm
B <sub>3</sub>	20 โวลต์ 1 นาที/0 โวลต์ 20 วินาที	เป็นรูพรุน ไม่เป็นรูปท่อ <mark>ที่ชัดเจ</mark> น	0
C <sub>1</sub>	20 โวลต์ 10 นาที/-5 โวลต์ 5 วินาที	<mark>ท่อสูงต่ำแตกต่าง</mark> กันชัดเจน <mark>ลู่เข้าหา</mark> เกาะกันเป็นกลุ่ม	50-85 nm
C <sub>2</sub>	20 โวลต์ 5 นาที/-5 โวลต์ 5 วินาที	ท่อสูงต่ำแตกต่างกันชัดเจน ผนังท่อขาด	50-85 nm
C <sub>3</sub>	20 โวลต์ 1 นาที/-5 โวลต์ 5 วินาที	ท่อสูงต่ำแตกต่างกันชัดเจน ท่อบางส่วนยังไม่สมบูรณ์	50-85 nm
D <sub>1</sub>	20 โวลต์ 10 นาที/-5 โวลต์ 20 วินาที	ท่อสูงไม่เท่ากัน ผนังท่อไม่เชื่อมติดกัน	50-150 nm
D <sub>2</sub>	20 โวลต์ 5 นาที/-5 โวลต์ 20 วินาที	ขนาดท่อแตกต่างกัน	25-150 nm
D <sub>3</sub>	20 โวลต์ 1 นาที/-5 โวลต์ 20 วินาที	เป็นรูพรุน ไม่เป็นรูปท่อที่ชัดเจน	20-100 nm

ตารางที่ 4.6 เปรียบเทียบลักษณะไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นในแต่ละสภาวะการสังเคราะห์

เมื่อเปรียบเทียบลักษณะของไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นทั้ง 12 สภาวะ การสังเคราะห์นั้น สรุปได้ดังตารางที่ 4.6 พบว่า ไม่มีสภาวะการสังเคราะห์ใดเลยที่เกิดออกไซด์รูปท่อที่ สมบูรณ์ ส่วนใหญ่ออกไซด์รูปท่อที่ได้จะมีผนังท่อที่ขาดหรือเชื่อมติดกัน สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญใน กระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง ในกรณีที่พื้นที่ตัวเร่งปฏิกิริยาเท่ากัน หากออกไซด์มีผนังท่อเชื่อม ติดกัน พื้นที่ผิว (Surface areas) ในการเกิดปฏิกิริยาก์จะน้อยกว่าออกไซด์ที่ผนังท่อไม่เชื่อมติดกัน ด้วย เหตุนี้จึงไม่นำสภาวะการสังเคราะห์ที่ผนังท่อเชื่อมติดกันหรือผนังท่อขาดมาเป็นเกณฑ์ในการเลือก สภาวะการสังเคราะห์ที่เหมาะสม ในส่วนของท่อที่มีความสูงต่ำไม่สม่ำเสมอกันคาดว่าอาจเกิดจากการที่ ระยะเวลาที่ใช้ในการสังเคราะห์ทั้งหมด (3 ชั่วโมง) มากเกินไป จึงได้เลือกสภาวะการสังเคราะห์ 20 โวลต์ 10 นาที/0 โวลต์ 20 วินาที (B<sub>1</sub>) และสภาวะการสังเคราะห์ 20 โวลต์ 10 นาที/-5 โวลต์ 20 วินาที (D<sub>1</sub>) มาเป็นตัวแทนในการทดลองต่อไป คือลดระยะเวลาการสังเคราะห์ทั้งหมดลง แสดงดังตารางที่ 4.7 และผลการทดลองการวิเคราะห์ลักษณะสัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (FESEM) แสดงดังตารางที่ 4.8

L	able	สารละลายนำไฟฟ้า	สภาวะก <mark>า</mark> รสังเคราะห์	ระยะเวลา ทั้งหมด
E <sub>1</sub>			<mark>2</mark> 0 โวลต์ 10 นาที/0 โวลต์ 20 วินาที	0.5 ชั่วโมง
E <sub>2</sub>	จาก $B_1$	0.20 MANULE	20 โวลต์ 10 นาที/ <mark>0 โว</mark> ลต์ 20 วินาที	1.0 ชั่วโมง
$E_3$		$0.30 \text{ M NH}_4\text{F}$	20 โวลต์ 10 นาที/0 โวล <mark>ต์</mark> 20 วินาที	1.5 ชั่วโมง
$F_1$		G(y) = (60 + 40)	<mark>20 โวลต์ 1</mark> 0 นาที/-5 โวล <mark>ต์ 2</mark> 0 วินาที	0.5 ชั่วโมง
$F_2$	จาก $D_1$	(60:40)	20 โวลต์ 10 นาที/-5 โวลต์ 20 วินาที	1.0 ชั่วโมง
$F_2$			20 โวลต์ 10 นาที/-5 โวลต์ 20 วินาที	1.5 ชั่วโมง

a		J	6 2
ตารางท 4.7	สภาวะการทดลองลดระยะเวลากา	รสงเคร	าะหทงหมด
-			



กำลังขยายเครื่อง FESEM Lable 15,000 เท่า 50,000 เท่า  $E_1$ 20 V 10 min / 0 V 20 sec 0.5 hr  $E_2$ 20 V 10 min / 0 V 20 sec 1.0 hr  $E_3$ 20 V 10 min / 0 V 20 sec 1.5 hr

ตารางที่ 4.8 ลักษณะสัณฐานของไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ทำการทดลองลดระยะเวลาการสังเคราะห์ ทั้งหมด

Lable	กำลังขยายเครื่อง FESEM		
Lable	15,000 เท่า	50,000 เท่า	
F <sub>1</sub> 20 V 10 min / -5 V 20 sec 0.5 hr		1. SP.000 1. SP.000 2. SP.000 2. SP.000 2. SP.007 2. SP.007	
F <sub>2</sub> 20 V 10 min / -5 V 20 sec 1.0 hr			
F <sub>3</sub> 20 V 10 min / -5 V 20 sec 1.5 hr		1. 50, 400 1. 50, 500 1. 500 1. 50, 500	

ตารางที่ 4.8 ลักษณะสัณฐานของไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ทำการทดลองลดระยะเวลาการสังเคราะห์ ทั้งหมด (ต่อ)

จากตารางที่ 4.8 ที่กำลังขยาย 15,000 เท่า จะเห็นว่าออกไซด์รูปท่อที่เกิดนั้นมีความสูง และขนาดท่อที่สม่ำเสมอกันมากขึ้นเมื่อลดระยะเวลาการสังเคราะห์ทั้งหมดลงเหลือ 0.5 1 และ 1.5 ชั่วโมง

#### 4.1.1.2 การวิเคราะห์ความหนาของออกไซด์

การศึกษาความหนาของชั้นออกไซด์นั้น สามารถวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Focused Ion Beam Scanning Electron Microscopes (FIB-FESEM) เทคนิค FIB จะทำหน้าที่เจาะ ผิวตัวอย่างหรือชิ้นงานด้วยลำไอออนโฟกัส เพื่อศึกษาดูโครงสร้างภายใน การทดลองเบื้องต้นนั้นได้ใช้ ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ได้จากกระบวนการแอโนไดเซซันมาทดลองหาความหนาของท่อที่เกิด แสดงดัง รูปที่ 4.2 ในการเจาะผิวหน้าของตัวเร่งปฏิกิริยาจะทำมุมประมาณ 30 องศากับพื้นผิว (รูป 4.2 ก) โดย ก่อนเจาะตัวอย่าง จะทำการเคลือบผิวออกไซด์ด้วยการพ่นแพลทินัมก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้ความสูงของ ท่อถูกทำลาย จากรูป 4.2 ข จะเห็นได้ว่ามีชั้นที่เกิดทั้งหมด 3 ชั้น คือ 1. แพลทินัมที่พ่นเคลือบไว้ 2. ชั้น ความหนาของออกไซด์รูปท่อของแผ่น TiO<sub>2</sub> ที่ผ่านการแอโนไดซ์ และ 3. ชั้นพื้นผิวของไทเทเนียม (Substrate)



รูปที่ 4.2 ภาพถ่าย FIB-FESEM แสดงความหนาชั้นออกไซด์ของแผ่น TiO2 ที่ผ่านการแอโนไดซ์

- n) ลักษณะกา<mark>รเจาะผิวห</mark>น้าแผ่นบนแผ่น TiO<sub>2</sub>
- ลักษณะของชั้นออกไซด์เมื่อผ่านการเจาะด้วยลำไอออนโฟกัส

จากนั้นได้นำแผ่น TiO<sub>2</sub> ที่สังเคราะห์ได้จากกระบวนการแอโนไดเซซันแบบ พัลส์ มาวิเคราะห์ความหนาของชั้นออกไซด์ที่เกิด โดยการเปรียบเทียบตามระยะเวลาที่ใช้การ สังเคราะห์ทั้งหมด คือ 0.5 1 1.5 และ 3 ชั่วโมง ซึ่งสภาวะที่นำมาเปรียบเทียบมีทั้งหมด 2 สภาวะ การสังเคราะห์คือ 20 โวลต์ 10 นาที / 0 โวลต์ 20 วินาที และ 20 โวลต์ 10 นาที / -5 โวลต์ 20 วินาที แสดงดังรูปที่ 4.3



รูปที่ 4.3 ภาพถ่าย FIB-FESEM แสดงความหนาชั้นออกไซด์ของแผ่น TiO<sub>2</sub> ที่ผ่านการแอโนไดซ์ ตามระยะเวลาที่ใช้การสังเคราะห์<mark>ทั้งหมด</mark>

้จากผลการทดลองพ<mark>บ</mark>ว่า เมื่อ<mark>ระ</mark>ยะเวลาที่ใช้การสังเคราะห์มากขึ้น ออกไซด์ที่

เกิดบนผิวเพิ่ม ซึ่งหมายความว่าท่อที่เกิดจะยาวมากขึ้น ส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาในการย่อยสลาย สารอินทรีย์ได้ดีมากขึ้นตามไปด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sun และคณะ ในปี 2011 ซึ่งทดลองแอ โนไดซ์ที่ระยะเวลาต่างกันคือ 10 30 60 และ 120 นาที พบว่า ระยะเวลา 120 นาที ทำให้ออกไซด์มี ความหนามากที่สุด และงานวิจัยของ Kontosa และคณะ ในปี 2012 มีการสังเคราะห์ไทเทเนียมได ออกไซด์แบบท่อนาโนด้วยกระบวนการแอโนไดซ์ที่ระยะเวลาต่างกัน คือ 1 2 และ 4 ชั่วโมง พบว่า ความหนาของออกไซด์มีขนาด 7 13.8 และ 24.8 ไมโครเมตร ตามลำดับ

#### 4.1.1.3 กา<mark>รวิเคราะห์การตอบส</mark>นองปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีแสง

การว**ิเคราะห์การตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟ้าเค**มีแสงของของตัวเร่งปฏิกิริยา เป็นการวัดอิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นในรู<mark>ปของค่าความหนาแน่นกระแสไ</mark>ฟฟ้าที่เกิดจากการฉายแสงผ่าน ตัวเร่งปฏิกิริยา (Photocurrent density) วิธีนี้สามารถนำมาใช้เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของปฏิกิริยาโฟโต คะตะไลซิสได้ในอีกทางหนึ่ง (Baeck, Zheng, Elton and Saeki, 2003)

เบื้อต้นได้การวิเคราะห์ได้นำแผ่นไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ผ่านกระบวนการแอ โนไดเซซันแบบพัลส์และแบบการจ่ายความต่างศักย์คงที่ ใช้ระยะเวลาการสังเคราะห์ทั้งหมด 3 ชั่วโมง มาฉายแสง เพื่อวัดความสามารถในการปลดปล่อยอิเล็กตรอนของตัวเร่งปฏิกิริยาเมื่อได้รับการกระตุ้น ด้วยแสง โดยทำการเปรียบเทียบค่าความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าจากการกระตุ้นด้วยแสง (Photocurrent density) ที่ความต่างศักย์ 500 มิลลิโวลต์ ซึ่งเป็นช่วงที่กระแสไฟฟ้าเริ่มเข้าสู่สภาวะ สมดุล แสดงดังตารางที่ 4.9 และรูปที่ 4.4

จายความตางคกยคงท เชระยะเวลาการสงเคราะหทงหมด 3 ชวเมง		
สภาวะการสังเคราะห์	Photocurrent density @ 500 mV (มิลลิแอมแปร์ต่อตารางเซนติเมตร)	
การแอโนไดซ์แบบพัลส์ (20 V 10 min / 0 V 20 sec , 3 hr)	0.0182	
การแอโนไดซ์จ่ายความต่างศักย์คงที่ (20 โวลต์ , 3 hr)	0.0106	

ตารางที่ 4.9 ค่า Photocurrent density ของแผ่น TiO<sub>2</sub> ที่ผ่านการแอโนไดซ์แบบพัลส์และแบบการ จ่ายความต่างศักย์คงที่ ใช้ระยะเวลาการสังเคราะห์ทั้งหมด 3 ชั่วโมง

#### พบว่าที่สภาวะการท<mark>ด</mark>ลองแอโนไดซ์แบบพัลส์ มีความหนาแน่นของ

กระแสไฟฟ้าจากการกระตุ้นด้วยแสง (Photocurrent density) มากกว่าการแอโนไดซ์แบบจ่ายความ ต่างศักย์คงที่ คือ 0.0182 มิลลิแอมแปร์ต่อตารางเซนติเมตร และ 0.0106 มิลลิแอมแปร์ต่อตาราง เซนติเมตร ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ref 09 -11) พบว่าเมื่อทำการสังเคราะห์ไทเทเนียม ไดออกไซด์รูปท่อด้วยกระบวนการแอโนไดเซซันแบบพัลส์ ให้ค่า Photocurrent density มากกว่าการ แอโนไดเซซันที่จ่ายความต่างศักย์แบบคงที่



#### รูปที่ 4.4 กราฟ Photocurrent density ของแผ่น TiO<sub>2</sub> ที่ผ่านการแอโนไดซ์แบบพัลส์และ แบบการจ่ายความต่างศักย์คงที่ ใช้ระยะเวลาการสังเคราะห์ทั้งหมด 3 ชั่วโมง

จากนั้นได้นำไทเทเนียมที่ผ่านการแอโนไซเซซันแบบพัลส์ทั้งหมดมา

เปรียบเทียบความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าจากการกระตุ้นด้วยแสง (Photocurrent density) ที่ ความต่างศักย์ 500 มิลลิโวลต์ จากตารางที่ 4.10 และรูปที่ 4.5 พบว่า สภาวะที่ให้ Photocurrent density มากที่สุด คือ 20 โวลต์ 5 นาที / -5 โวลต์ 5 วินาที ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.0337 มิลลิแอมแปร์ต่อ ตารางเซนติเมตร



รูปที่ 4.5 กราฟ Photocurrent density ของแผ่น TiO<sub>2</sub> ที่ผ่านการแอโนไดซ์แบบพัลส์ทั้งหมด


สภาวะการสังเคราะห์		ระยะเวลา ทั้งหมด	Photocurrent density @ 500 mV (มิลลิแอมแปร์ต่อตารางเซนติเมตร)	
A <sub>1</sub>	20 โวลต์ 10 นาที/0 โวลต์ 5 วินาที		0.0301	
A <sub>2</sub>	20 โวลต์ 5 นาที/0 โวลต์ 5 วินาที		0.0298	
A <sub>3</sub>	20 โวลต์ 1 นาที/0 โวลต์ 5 วินาที		0.0248	
B <sub>1</sub>	20 โวลต์ 10 นาที/0 โวลต์ 20 วินาที		0.0182	
B <sub>2</sub>	20 โวลต์ 5 นาที/0 โวลต์ 20 วินาที		0.0208	
B <sub>3</sub>	20 โวลต์ 1 นาที/0 โวลต์ 20 วินาที	2 ชั่วโนง	0.0145	
C <sub>1</sub>	20 โวลต์ 10 นาที/-5 โวลต์ 5 วินาที	2 0 1611	0.0121	
C <sub>2</sub>	20 โวลต์ 5 นาที/-5 โวลต์ 5 วินาที	dh i	0.0337	
C <sub>3</sub>	20 โวลต์ 1 นาที/-5 โวลต์ 5 วินาที		0.0234	
D <sub>1</sub>	20 โวลต์ 10 นาที/-5 โวลต์ 20 วินาที		0.0106	
D <sub>2</sub>	20 โวลต์ 5 นาที/-5 โวลต์ 20 วินาที		0.0188	
D <sub>3</sub>	20 โวลต์ 1 นาที/-5 โวลต์ 20 วินา <mark>ที</mark>		0.0145	
E <sub>1</sub>	20 โวลต์ 10 นาที/0 โวลต์ 20 วิน <mark>า</mark> ที	0.5 ชั่วโมง	0.0196	
E <sub>2</sub>	20 โวลต์ 10 นาที/0 โวลต์ 20 <mark>วิน</mark> าที	1.0 ชั่วโมง	0.0209	
E <sub>3</sub>	20 โวลต์ 10 นาที/0 โวลต์ <mark>2</mark> 0 วินาที	1.5 ชั่วโมง	0.0236	
$F_1$	20 โวลต์ 10 นาที/-5 โว <mark>ลต์</mark> 20 <mark>วินาที</mark>	0.5 ชั่วโมง	0.0185	
F <sub>2</sub>	20 โวลต์ 10 นาที/-5 <mark>โวล</mark> ต์ 2 <mark>0 วินาที</mark>	<ol> <li>1.0 ชั่วโมง</li> </ol>	0.0241	
$F_2$	20 โวลต์ 10 นาที/-5 <mark>โวลต์</mark> 20 วินาที	1.5 ชั่วโมง	0.0227	

ตารางที่ 4.10 ค่า Photocurrent density ของแผ่น TiO2 ที่ผ่านการแอโนไดซ์แบบพัลส์

นอกจากนี้ยังได้ทำการเปรียบเทียบความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าจากการ

กระตุ้นด้วยแสง (Photocurrent density) ที่ความต่างศักย์ 500 มิลลิโวลต์ ในด้านของระยะเวลาการ สังเคราะห์ทั้งหมด โดยแบ่งเป็น 2 สภาวะการสังเคราะห์คือ 20 โวลต์ 10 นาที / 0 โวลต์ 20 วินาที และ 20 โวลต์ 10 นาที / -5 โวลต์ 20 วินาที ทั้ง 2 สภาวะการทดลองนั้นใช้ระยะเวลาการสังเคราะห์ ทั้งหมดที่ 0.5 1 1.5 และ 3 ชั่วโมง แสดงดังรูปที่ 4.6



รูปที่ 4.6 กราฟ Photocurrent density <mark>ขอ</mark>งแผ่น TiO<sub>2</sub> ที่ผ่านการแอโนไดซ์แบบพัลส์ โดยเปรียบเทียบระยะเวลากา<mark>รสังเคร</mark>าะห์ทั้งหมด 0.5 1 1.5 และ 3 ชั่วโมง

เมื่อเปรียบเทียบ Ph<mark>o</mark>tocurre<mark>nt</mark> density ที่ระยะเวลาการสังเคราะห์ทั้งหมด

คือ 0.5 1 1.5 และ 3 ชั่วโมง ของสภาวะการสังเคราะห์ 20 โวลต์ 10 นาที / 0 โวลต์ 20 วินาที (E<sub>1</sub> E<sub>2</sub> E<sub>3</sub> และ B<sub>1</sub>) พบว่า Photocurrent density สูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 0.0236 มิลลิแอมแปร์ต่อตาราง เซนติเมตร ที่ระยะเวลาการสังเคราะห์ทั้งหมด 1.5 ชั่วโมง ที่สภาวะการสังเคราะห์ 20 โวลต์ 10 นาที / -5 โวลต์ 20 วินาที (F<sub>1</sub> F<sub>2</sub> F<sub>3</sub> และ D<sub>1</sub>) นั้น Photocurrent density ที่ระยะเวลาการสังเคราะห์ทั้งหมด 1.0 และ 1.5 ชั่วโมง ให้ค่าที่ใกล้เคียงกัน คือ 0.0241 มิลลิแอมแปร์ต่อตารางเซนติเมตร และ 0.0227 มิลลิแอมแปร์ต่อตารางเซนติเมตร ตามลำดับ และที่เหมือนกันทั้งสองสภาวะการทดลองคือ ระยะเวลาการสังเคราะห์ทั้งหมดที่ 3 ชั่วโมง ให้ Photocurrent density ที่ต่ำที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ (ref 12) ที่กล่าวว่าเมื่อใช้ระยะเวลาในการสังเคราะห์นานขึ้น จะทำให้เกิดท่อที่ยาวมากขึ้น ตามไปด้วย ซึ่งท่อที่ยาวเกินไปอาจจะเป็นการไปลด Recombination center ทำให้เกิดการกลับมา รวมตัวกันระหว่างอิเล็กตรอนและช่องว่างได้ง่ายขึ้น และออกไซด์รูปท่อที่ยาวเกินไปอาจไปบดบังแสง ทำให้บางส่วนไม่ได้รับการฉายแสง ส่งผลให้ค่าความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าจากการกระตุ้นด้วยแสง ลดลง

จากที่กล่าวมาข้างต้นคาดว่าสภาวะการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสม คือ 20 โวลต์ 5 นาที / -5 โวลต์ 5 วินาที ใช้ระยะเวลาการสังเคราะห์ 1.5 ชั่วโมง เนื่องจาก

 จากตารางที่ 4.10 และรูปที่ 4.5 จากสภาวะที่ใช้ระยะเวลาการ สังเคราะห์ทั้งหมด 3 ชั่วโมง พบว่าสภาวะที่ให้ Photocurrent density มากที่สุด คือ 20 โวลต์ 5 นาที / -5 โวลต์ 5 วินาที

เมื่อเปรียบเทียบในด้านของระยะเวลาที่ใช้ในการสังเคราะห์ทั้งหมด
 คือ 0.5 1 1.5 และ 3 ชั่วโมง พบว่าที่ระยะเวลาการสังเคราะห์ 1.5 ชั่วโมงนั้นให้ Photocurrent
 density สูงที่สุด

จึงได้ทำการสังเคราะห์ที่สภาวะการทดลอง 20 โวลต์ 5 นาที / -5 โวลต์ 5 วินาที ระยะเวลาการสังเคราะห์ทั้งหมด 1.5 ชั่วโมง แสดงผล Photocurrent density ที่ความต่างศักย์ 500 มิลลิโวลต์ ดังตารางที่ 4.11 และรูปที่ 4.7 ซึ่งพบว่าที่ระยะเวลาการสังเคราะห์ 1.5 ชั่วโมง ให้ Photocurrent density ที่สูงกว่าระยะเวลาการสังเคราะห์ 3 ชั่วโมง คือ 0.0410 มิลลิแอมแปร์ต่อ ตารางเซนติเมตร และ 0.0337 มิลลิแอมแปร์ต่อตารางเซนติเมตร ตามลำดับ

ตารางที่ 4.11 ค่า Photocurrent density ที่สภาวะการสังเคราะห์ 20 โวลต์ 5 นาที / -5 โวลต์ 5 วินาที ระยะเวลาการสังเคราะห์ทั้งหมด 1.5 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับ 3 ชั่วโมง

สภาวะการสังเคราะห์	ระยะเวลา ทั้งหมด	Photocurrent density @ 500 mV (มิลลิแอมแปร์ต่อตารางเซนติเมตร)
20 โวลต์ 5 นาที/5 โวลต์ 5 วินาที	1. <mark>5</mark> ชั่วโมง	0.0394
20 โวลต์ 5 นาที/0 โวลต์ 5 วินาที	<mark>3 ช</mark> ั่วโมง	0.0337

ดังนั้นจึงได้เลือกสภา<mark>วะการสัง</mark>เคราะห์ 20 โวลต์ 5 นาที / -5 โวลต์ 5 วินาที

ใช้ระยะเวลาการสังเคราะห์ทั้งหมด 1.5 ชั่วโมง เป็นสภาวะที่เหมาะสม และนำไปใช้กำหนดในการ ทดลองต่อไปทุกการทดลอง



รูปที่ 4.7 กราฟ Photocurrent density ที่สภาวะการสังเคราะห์ 20 โวลต์ 5 นาที / -5 โวลต์ 5 วินาที ระยะเวลาการสังเคราะห์ทั้งหมด 1.5 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับ 3 ชั่วโมง

### 4.1.1.4 การวิเคราะห์หาโครงสร้างผลึกของออกไซด์

วิเคราะห์โครงสร้างผลึกของออกไซด์ด้วยเครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบน รังสีเอ็กซ์ หรือ X-ray Diffractometer (XRD) ของตัวอย่างที่สภาวะการสังเคราะห์ 20 โวลต์ 5 นาที / -5 โวลต์ 5 วินาที (1.5 ชั่วโมง) โดยใช้ Cu-K (**λ** = 1.54060 อังสตรอม) กวาดมุม 2**θ** ตั้งแต่ 20 – 80 องศา ที่อัตราการกราด (scan rate) 0.02 องศาต่อ 0.2 วินาที แสดงผลดังรูปที่ 4.8 พบว่าไทเทเนียมได ออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้เกิดเป็นโครงสร้างผลึกของไทเทเนียมที่ตำแหน่ง 35.16° 38.49° 40.00° 53.06° 63.03° และ 70.68° ตามลำดับ (เปรียบเทียบกับข้อมูลมาตรฐาน JCPDS หมายเลข 44-1294) และ เกิดเป็นโครงสร้างผลึกรูปแบบอนาเทส ปรากฏที่ตำแหน่ง 25.15° 37.88° 38.70° 48.12° 53.90° และ 70.44° ตามลำดับ (เปรียบเทียบกับข้อมูลมาตรฐาน JCPDS หมายเลข 21-1272) ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ref 13-19) ที่แสดงให้เห็นว่าออกไซด์ที่เกิดเป็นโครงสร้างผลึกแบบอนาเทส ที่มีแผ่นไทเทเนียมเป็นสารตั้งต้น (Substrate)



รูปที่ 4.8 วิเคราะห์โครงสร้างผลึกของออกไซด์ที่เกินบนพื้นผิวของแผ่น TiO<sub>2</sub> ด้วยเครื่อง XRD

โดยทั่วไปโครงสร้างผลึกแบบอนาเทสนิยมใช้ในปฏิกิริยาการเร่งด้วยแสง เนื่องจากโครงสร้างแบบอนาเทสจะให้ประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยาสูงกว่าโครงสร้างรูไทล์ ด้วย โครงสร้างของอนาเทสที่มีแถบช่องว่างพลังงานที่สูงกว่ารูไทล์ ทำให้การรวมตัวกันใหม่ของคู่อิเล็กตรอน และโฮลมีอัตราการเกิดที่ต่ำ นอกจากนี้โครงสร้างแบบอนาเทสสามารถเตรียมได้ที่อุณหภูมิต่ำ ทำให้มี พื้นที่ผิวสูง ดังนั้นจึงสามารถผลิตไฮดรอกซิลเรดิคอลได้มาก ส่งผลให้การเกิดปฏิกิริยาในการบำบัด มลพิษนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่า

### 4.1.1.5 การวิเคราะห์ค่าดูดกลืนแสงของตัวเร่งปฏิกิริยา

การศึกษาคุณสมบัติของการดูดกลืนแสงของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยเครื่อง UV/VIS Spectrophotometer ที่ช่วงความยาวคลื่น 190 – 600 ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างโดย เปรียบเทียบแผ่นไทเนียมที่ใช้เป็นวัสดุตั้งต้นกับแผ่นไทเทเนียนที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการแอโนได เซซันแบบพัลส์ (สภาวะการสังเคราะห์ 20 โวลต์ 5 นาที / -5 โวลต์ 5 วินาที, 1.5 ชั่วโมง) และแบบจ่าย ความต่างศักย์คงที่ แสดงดังรูปที่ 4.9 จะเห็นได้ว่าตัวอย่างที่สังเคราะห์ได้จากกระบวนการแอโนไดเซซัน แบบพัลส์ มีการตอบสนองต่อแสงที่มากกว่าการแอโนไดเซซันที่จ่ายความต่างศักย์คงที่ โดยจะตอบสนองต่อ สนองต่อแสงในช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ 190 – 360 นาโนเมตร หรืออยู่ในช่วงของรังสียูวี ส่วนแผ่น ไทเทเนียมที่ใช้เป็นวัสดุตั้งต้นนั้นมีการตอบสนองต่อแสงน้อยมาก หรือแทบจะไม่มีการตอบสนองต่อแสงเลย



รูปที่ 4.9 การดูดกลืนแสงของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยเครื่อง UV/VIS Spectrophotometer

### 4.1.2 การทดลอง<mark>สำหรับการหาค่าซีโอดีด้วยการบว</mark>นกา<mark>รโฟโ</mark>ตอิเล็กโตรคะตะไลซิส

ในการหาค่าซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส โดยใช้ไทเทเนียมได ออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้ในกระบวนการแอโนไดเซซันแบบพัลส์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ในการทดลองจะใช้ ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้เป็นขั้วไฟฟ้าใช้งาน (Working electrode) แพลทินัม (Pt) เป็น ขั้วไฟฟ้าคู่ใช้งาน (Counter electrode) และใช้ Ag/AgCl เป็นขั้วไฟฟ้าอ้างอิง (Reference electrode) แหล่งกำเนิดแสงใช้หลอดไฟ LED (ความยาวคลื่น 365 นาโนเมตร) ขนาด 5 วัตต์

### 4.1.2.1 การหาค่าซีโอดีด้วยการบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสโดยใช้ ชุดการทดลองที่ 1

สารละลายมาตรฐานที่ใช้ในชุดการทดลองนี้คือสารละลายมาตรฐานกลูโคส (D-glucose) มีโซเดียมซัลเฟต (Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) 0.1 M เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ กำหนดค่าความต่างศักย์ 0.5 โวลต์ ปริมาณน้ำ 5 มิลลิลิตร และพื้นที่ผิวตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์ที่สัมผัสกับน้ำ 1 ตารางเซนติเมตร เริ่มต้นได้ทดลองโดยแปรเปลี่ยนค่าความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานกลูโคส 3 ความเข้มข้น คือ 10 50 และ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร จ่ายความต่างศักย์เป็นเวลา 100 วินาที ทุกความ เข้มข้นใช้แผ่นไทเทเนียมไดออกไซด์แผ่นเดียว ผลการทดลองแสดงดังรูปที่ 4.10



รูปที่ 4.10 การตอบสนองข<mark>องกร</mark>ะแสไฟฟ้าจากกระบ<mark>วนก</mark>ารโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส ของชุดการทด<mark>ล</mark>องที่ 1 (ครั้งที่1)

จากผลการทดลองพบว่า ที่กลูโคสเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร กระแสไฟฟ้า ที่วัดได้มีค่าต่ำกว่าแบลงค์ (น้ำปราศจากไอออนที่เติม Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 0.1 M เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์) ซึ่ง ไม่สามารถนำไปคำนวณหาค่าซีโอดีได้ แต่ที่ความเข้มข้นกลูโคส 100 และ 500 มิลลิกรัมต่อลิตรนั้น กระแสไฟฟ้าที่วัดออกมาได้มีค่าสูงกว่าแบลงค์ แต่กราฟกระแสไฟฟ้าที่ได้จากสารละลายมาตรฐาน กลูโคสและแบลงค์ไม่บรรจบกัน แสดงว่าสารอินทรี่ย์ถูกออกซิไดซ์ไม่หมด จึงเพิ่มระยะเวลาในการทำ ปฏิกิริยาเป็น 5 นาที (300 วินาที) ใช้สารละลายมาตรฐานกลูโคสที่ความเข้มข้นต่ำ ๆ คือ 1 และ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ผลการทดลองแสดงดังรูปที่ 4.11 พบว่ากราฟที่ได้จากกระแสไฟฟ้าจากสารละลาย มาตรฐานกลูโคสทุกความเข้มข้นรวมถึงแบลงค์ เป็นเส้นเดียวกัน สันนิษฐานว่าความเข้มข้นของกลูโคส อาจจะต่ำเกินไป ทำให้กระแสไฟฟ้าที่วัดออกมาได้มีค่าไม่แตกต่างกัน จึงทำการทดลองซ้ำ โดยเพิ่มความ เข้มข้นของสารละลายมาตรฐานกลูโคสเท่ากับ 50 และ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งก็พบว่ากระแสไฟฟ้าที่ วัดออกมามีค่าไม่แตกต่างกันเช่นเดิม แสดงผลการทดลองแสดงดังรูปที่ 4.12



รูปที่ 4.11 การตอบสนองขอ<mark>งกร</mark>ะแสไฟฟ้าจากกระบ<mark>วนก</mark>ารโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส ของชุดการทด<mark>ล</mark>องที่ 1 (ครั้งที่2)





รูปที่ 4.12 การตอบสนองข<mark>องกร</mark>ะแสไฟฟ้าจากกระบ<mark>วนก</mark>ารโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส ของชุดการทด<mark>ล</mark>องที่ 1 (ครั้งที่3)

จากผลการทดลองหาค่าซีโอดีด้วยการบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสของ ชุดการทดลองที่ 1 ที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น จะเห็นว่ากราฟที่ได้จากสารละลายมาตรฐานกลูโคสและ แบลงค์นั้นเป็นเส้นเดียวกัน ทำให้ไม่สามารถหาค่าซีโอดีได้ เนื่องจากไม่มีพื้นที่ใต้กราฟที่แตกต่างกัน ระหว่างสารละลายมาตรฐานกลูโคสและแบลงค์ จึงได้ตั้งสมมติฐานว่า อาจเกิดจากการที่ไม่ได้ใช้หัวหนีบ ปากจระเข้คีบที่ขั้วใช้งาน (Working electrode) และขั้วไฟฟ้าช่วย (Counter electrode) โดยตรง จึง ได้ทำการแก้ไขโดยเปลี่ยนถังปฏิกรณ์ใหม่

### 4.1.2.2 การหาค่าซีโอดีด้วยการบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสโดยใช้ ชุดการทดลองที่ 2

ในการทดลองหาค่าซีโอดีของชุดการทดลองที่ 2 ถังปฏิกรณ์ทำขึ้นมาจาก ซิลิโคน แหล่งกำเนิดแสงทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป ครอบตัวถังปฏิกรณ์ (ดังรูป 3.7) ในชุดการทดลองนี้จะ

ทำการหาสภาวะต่าง ๆ ที่เหมาะสมก่อนที่จะเริ่มวัดค่าซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส 1) ศึกษาประเภทของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ; ได้ทำการแปรเปลี่ยน ประเภทของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ 2 ชนิดคือ โซเดียมซัลเฟต (Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) และโซเดียมไดไฮโดรเจน ฟอตเฟต (NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>) ความเข้มข้น 1.0 โมลาร์ กำหนดความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานกลูโคส 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ใช้ปริมาณน้ำ 3 มิลลิลิตร จ่ายความต่างศักย์ที่ 0.3 โวลต์ เป็นระยะเวลา 5 นาที (300 วินาที) และในการทดลองนี้ใช้แผ่นไทเทเนียมไดออกไซด์เพียงแผ่นเดียว ผลการทดลองแสดงดังรูป ที่ 4.13 พบว่าทั้งแบลงค์และสารละลายมาตรฐานกลูโคสที่มีโซเดียมซัลเฟตเป็นอิเล็กโทรไลต์ ให้ กระแสไฟฟ้าที่มากกว่าสารละลายอิเล็กโทรไลต์โซเดียมซัลเฟต ดังนั้นในการทดลองขั้นต่อไปจะใช้ โซเดียมซัลเฟต (Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) เป็นสารละลายอิเล็กโทตไลต์ในทุกการทดลอง



รูปที่ 4.13 การตอบสนอ<mark>งของกระแสไฟฟ้าที่เปรียบเทียบประเภทขอ</mark>งสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ของชุดการทดลองที่ 2

2) ศึกษาความต่างศักย์ที่เหมาะสม ; ทำการแปรเปลี่ยนค่าความต่าง

ศักย์ที่ 0.5 โวลต์ และ 2.0 โวลต์ โดยระยะเวลาการจ่ายเท่ากับ 5 นาที กำหนดสารละลายมาตรฐาน กลูโคสเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร มีโซเดียมซัลเฟต 0.1 โมลาร์เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ปริมาณน้ำ 3 มิลลิลิตร และใช้แผ่นไทเทเนียมไดออกไซด์เพียงแผ่นเดียว แสดงผลการทดลอง ดังรูปที่ 4.14



รูปที่ 4.14 เปรียบเทียบการตอบส<mark>นอง</mark>ของกระแสไฟฟ้าที่ค<mark>วาม</mark>ต่างศักย์ 0.5 โวลต์และ 2.0 โวลต์ ที่สารละลายอิเล็กโทรไลต์โซเดียมซัลเฟต 0.1 โมลาร์ ของชุดการทดลองที่ 2

จากผลการทดลองพบว่าที่ความต่างศักย์ 0.5 โวลต์ และ 2.0 โวลต์ทั้งสอง สภาวะพบว่า กราฟที่ได้จากกระแสไฟฟ้าจากสารละลายมาตรฐานกลูโคสและแบลงค์เป็นเส้นเดียวกัน จึงได้ทดลองโดยการเพิ่มความเข้มข้นของสารละลายอิเล็กโทรไลต์โซเดียมซัลเฟต 0.1โมลาร์ เป็น 1.0 โมลาร์ ผลการทดลองแสดงดังรูปที่ 4.15 พบว่าที่ความต่างศักย์ 0.5 โวลต์ มีความต่างเกิดขึ้นของ กระแสไฟฟ้าที่ได้จากสารละลายมาตรฐานกลูโคสและแบลงค์ แต่กราฟกระแสที่ได้จากแบลงค์นั้นสูงกว่า กราฟที่ได้จากสารละลายมาตรฐานกลูโคส ส่วนที่ความต่างศักย์ 2.0 โวลต์ กราฟที่ได้นั้นยังคงเป็นเส้น เดียวกันอยู่เช่นเดิม



รูปที่ 4.15 เปรียบเทียบการตอบส<mark>นอ</mark>งของกระแสไฟฟ้าที่ค<mark>วาม</mark>ต่างศักย์ 0.5 โวลต์และ 2.0 โวลต์ ที่สารละลายอิเล็กโทรไลต์โซเดียมซัลเฟต 1.0 โมลาร์ ของชุดการทดลองที่ 2

3) ศึกษาประเภทของขั้วไฟฟ้าร่วม (Counter electrode); ทำการ เปรียบเทียบขั้วไฟฟ้าร่วม 2 ชนิด คือ ลวดแพลทินัม และแผ่นการ์ไฟต์ ซึ่งกำหนดความเข้มข้นของ สารละลายมาตรฐานกลูโคสเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร มีโซเดียมซัลเฟต 0.1 โมลาร์เป็นอิเล็กโทรไลต์ ปริมาณน้ำ 3 มิลลิลิตร จ่ายความต่างศักย์ 0.3 โวลต์เป็นระยะเวลา 5 นาที และใช้แผ่นไทเทเนียมได ออกไซด์เพียงแผ่นเดียว จากผลการทดลองรูปที่ 4.16 พบว่า กราฟกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากแผ่นการ์ไฟต์ เป็นขั้วไฟฟ้าร่วมของสารละลายมาตรฐานกลูโคสและแบลงค์นั้นมีความต่างกันน้อยมาก ส่วนกราฟที่ได้ จากขดลวดแพลทินัมเป็นขั้วไฟฟ้าร่วม กระแสไฟฟ้าที่เกิดจากสารละลายมาตรฐานกลูโคสและแบลงค์มี ความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้กระไฟฟ้าที่เกิดจากขดลวดแพลทินัมยังสูงกว่ากระแสไฟฟ้า จากแผ่นการ์ไฟต์อีกด้วย



รูปที่ 4.16 การตอบสนองของกระแสไฟ<mark>ฟ้า</mark>ที่เปรียบเทียบประเภทของขั้วไฟฟ้าร่วม

- ก) แผ่นการ์ไฟต์
- ข) ลวดแพลทินัม

# ุ 4.1.2.3 การหาค่าซีโอด<mark>ีด้ว</mark>ยการบ<mark>วน</mark>การโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสโดยใช้

### ชุดการทดลองที่ 3

ในการทดลองชุดที่ 3 นั้นจะใช้ถังปฏิกรณ์ที่ทำจากซิลิโคนเช่นเดิม แต่ในวัด กระแสไฟฟ้านั้นจะใช้เครื่องดิจิตอล มัลติมิเตอร์แทน ซึ่งการทดลองชุดที่ 1 และ 2 นั้นในการวัด กระแสไฟฟ้าและจ่ายความต่างศักย์จะใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้นเอง (รูปที่ 3.6) ฉะนั้นจึงต้องทำการหา สภาวะต่าง ๆ ที่เหมาะสมใหม่ ซึ่งทุกการทดลองจะใช้ขั้วไฟฟ้าร่วมคือ ลวดแพลทินัม โดยในชุดการ ทดลองนี้มีขั้นตอนและผลการทดลองดังนี้

 ศึกษาความต่างศักย์ที่เหมาะสม ; ทำการแปรเปลี่ยนค่าความต่าง ศักย์ดังนี้ 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 และ 1.0 โวลต์ ระยะเวลาการจ่ายเท่ากับ 5 นาที กำหนสารละลาย มาตรฐานกลูโคสเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ใช้โซเดียมซัลเฟต 0.1 โมลาร์เป็นอิเล็กโทรไลต์ ปริมาณน้ำ 3 มิลลิลิตร โดยครั้งนี้จะใช้แผ่นไทเทเนียมไดออกไซด์ 1 แผ่นต่อ 1 ความต่างศักย์ และในการวัด ตัวอย่างแต่ละครั้งนั้นจะวัดทั้งหมด 4 ซ้ำ จากนั้นจะนำมาหาค่าเฉลี่ย ซึ่งทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำตัวอย่างออก จะต้องทำการคีบสายไฟใหม่ทุกครั้ง ผลการทดลองแสดงดังรูปที่ 4.17 ซึ่งพบว่ากระแสที่เกิดขึ้นนั้นมีค่า ใกล้เคียงกัน ส่วนกระแสที่เกิดจากความต่างศักย์ 1.0 โวลต์ (รูปที่ 4.17 ฉ) นั้นให้กระแสที่สูงที่สุด แต่ พบว่าที่ความต่างศักย์นี้ กระแสไฟฟ้าที่เกิดจากแบลงค์นั้นมีมากกว่ากระแสไฟฟ้าที่เกิดจากสารละลาย มาตรฐาน นอกจากนี้ กราฟที่เกิดขึ้นของทุกการทดลองนั้นกระแสไฟฟ้าระหว่างแบลงค์ และสารละลาย มาตรฐานมิเส้นที่ไม่บรรจบกัน ซึ่งหมายความว่าสารละลายเกิดการออกซิไดซ์ไม่หมด หรือเกิดการย่อย สลายไม่สมบูรณ์ แต่จะเลือกใช้ความต่างศักย์ที่ 0.5 โวลต์ เป็นตัวแทนในการทดลองต่อไป เนื่องจาก กระแสไฟฟ้าที่เกิดจากแบลงค์ และสารละลายมาตรฐานมีระยะห่างที่มากกว่าสภาวะอื่น ๆ



รูปที่ 4.17 เปรียบเทียบการตอบสนองของกระแสไฟฟ้าที่ความต่างศักย์ต่าง ๆ ของชุดการทดลองที่ 2

 เมื่อได้ค่าความต่างศักย์ที่เหมาะสมแล้ว คือ 0.5 โวลต์ จึงได้ทำการ ทดลองหาค่าซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส โดยทำการหาค่าซีโอดีจากสารละลาย มาตรฐานกลูโคสทั้งหมด 7 ความเข้มขั้น ตั้งแต่ 5 – 500 มิลลิกรัมต่อลิตร (แสดงดังตารางที่ 3.5) ใช้ โซเดียมซัลเฟต 0.1 โมลาร์เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ปริมาณน้ำ 3 มิลลิลิตร จ่ายความต่างศักย์ที่ 0.5 โวลต์ ระยะเวลา 5 นาที และใช้แผ่นไทเทเนียมไดออกไซด์เพียงแผ่นเดียวเท่านั้น



รูปที่ 4.18 การตอบสนองของกระแสไฟ<mark>ฟ้าจากกระบวนการ</mark>โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส ของชุดการทดลองที่ 3 (ครั้งที่ 1)

จากผลการทดลองรูปที่ 4.18 พบว่ามีเพียงสารละลายมาตรฐานกลูโคสที่ ความเข้มข้น 5 และ 75 มิลลิกรัมต่อลิตรเท่านั้น ที่กระแสไฟฟ้าที่ได้นั้นสูงกว่าแบลงค์ สันนิษฐานว่าอาจ เกิดจากการที่ใช้แผ่นไทเทเนียมเพียงแผ่นเดียวต่อทุกความเข้มข้น ส่งผลให้แผ่นนั้นหมดสภาพ 3) จากการที่ทดลองวัดซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไล ซิสครั้งที่ 1 แล้วพบปัญหาจึงแก้ไขโดยจะใช้แผ่นไทเทเนียมไดออกไซด์ 1 แผ่นต่อ 1 ความเข้มข้นของ สารละลายมาตรฐาน ซึ่งจากผลการทดลองแสดงดังรูปที่ 4.19



รูปที่ 4.19 การตอบสนองของกระแสไฟฟ้าจากกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส ของชุดการทดลองที่ 3 (ครั้งที่ 2)

ซีโอดีทางทฤษฎี (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ซีโอดีจากกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส (มิลลิกรัมต่อลิตร
50	244.18478
100	694.16055
200	598.11021
500	776.40833

ตารางที่ 4.12 ค่าซีโอดีจากกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสเปรียบเทียบกับค่าซีโอดีทฤษฎี

จากผลการทดลองรูปที่ 4.19 พบว่าสารละลายมาตรฐานกลูโคสที่ความ

เข้มข้น 5 และ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร กราฟกระแสไฟฟ้าที่ได้จากแบลงค์สูงกว่าสารละลายม<sup>้</sup>าตรฐาน ซึ่ง ไม่สามารถนำมาคำนวณหาค่าซีโอดีได้ ส่วนความเข้มข้นที่สามารถคำนวณหาค่าซีโอดีได้ แสดงดังตาราง ที่ 4.12 พบว่าค่าซีโอดีที่ได้จากกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสนั้นมีค่าไม่ใกล้เคียงกับค่าซีโอดี ทางทฤษฏี ซึ่งเมื่อนำไปสร้างกราฟความสัมพันธ์<mark>นั้นได้ค่า</mark> R<sup>2</sup> เพียง 0.4782 แสดงดังรูปที่ 4.20



รูปที่ 4.20 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าซีโอดีทางทฤษฎีและค่าซีโอดีจาก กระบวนการโฟโตอิเล็กโตร-คะตะไลซิสของชุดการทดลองที่ 3

จากการที่ค่าซีโอดีที่ได้จากกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสนั้นไม่ เท่ากับค่าซีโอดีทางทฤษฏี จึงได้ทำการตั้งสมมติฐานว่าอาจเกิดจากการคีบสายไฟใหม่ทุกครั้ง จึงได้ทำ การทดลองทดสอบสมมติฐาน โดยการวัดกระแสไฟฟ้าที่ได้จากแบลงค์เพียงอย่างเดียวทั้งหมด 4 ซ้ำ โดยที่ไม่มีการคีบสายไฟใหม่ การเปลี่ยนน้ำตัวอย่างจะใช้ Dropper ในการดูดน้ำตัวอย่างออก ซึ่งผล การทดลองแสดงดังรูปที่ 4.21 พบว่ากราฟกระแสที่ได้จากแต่ละซ้ำนั้นใกล้เคียงกันมาก ซึ่งเมื่อ คำนวณหาพื้นที่ใต้กราฟจากแต่ละซ้ำ ก็พบว่าค่าที่ได้มีค่าใกล้เคียงเช่นเดียวกัน



รูปที่ 4.21 การตอบสนองของกระแสไฟฟ้าจากแบลงค์ โดยไม่มีการคีบสายไฟใหม่



รูปที่ 4.22 กราฟมาตรฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าพื้นที่ใต้กราฟ (Q<sub>net</sub>) กับค่าซีโอดีทางทฤษฎี ของชุดการทดลองที่ 3 (ครั้งที่ 1)



รูปที่ 4.23 กราฟมาตรฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าพื้นที่ใต้กราฟ (Q<sub>net</sub>) กับค่าซีโอดีทางทฤษฎี ของชุดการทดลองที่ 3 (ครั้งที่ 2)



รูปที่ 4.24 กราฟมาตรฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าพื้นที่ใต้กราฟ (Q<sub>net</sub>) กับค่าซีโอดีทางทฤษฎี ของชุดการทดลองที่ 3 (ครั้งที่ 3)

จากการทดลองซ้ำของการสร้างกราฟมาตรฐานด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็ก โตรคะตะไลซิส เพื่อนำไปใช้ในการอ่านค่าซีโอดี ในรูปที่ 4.23 และ 4.24 นั้นพบว่าค่า R<sup>2</sup> ที่ได้มีค่าต่ำ มาก คือ 0.2769 และ 0.0836 ตามลำดับ จึงได้นำค่าพื้นที่ใต้กราฟของทั้ง 3 ซ้ำมาเปรียบเทียบกันดัง ตารางที่ 4.13 พบว่า ที่ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไฮโดรเจนพลาเลต (KHP) เดียวกันนั้น แต่พื้นที่ใต้กราฟที่คำนวณได้จากแต่ละซ้ำนั้น มีค่าไม่ใกล้เคียงกันเลย

		63		
ค่าซีโอดีทางทฤษฎี	Qnet (mC)			
(มิลลิกรัมต่อลิต)	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	
10	-	13.613	16.721	
20	18.123	30.940	24.495	
50	26.2 <mark>3</mark> 4	46.868	57.020	
100	28.523	60.639	51.754	
150	<mark>32.1</mark> 66	54.284	55.988	
200	32.678	44.070	59.804	
250	52.666	52.438	60.806	
300	47.659	49.645	54.852	
400	51.972	49.682	46.983	
500	64.841	54.284	39.421	

ตารางที่ 4.13 เปรียบเทียบค่าพื้นที่ใต้กราฟจากสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไฮโดรเจนพลาเลต

### 4.2 ซิงค์ออกไซด์

ในการศึกษานี้ได้ทำการศึกษาคุณลักษณะและคุณสมบัติของซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ขึ้นเพื่อ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส ซึ่งในที่นี้จะนำเสนอในส่วนของผล การศึกษาคุณลักษณะของซิงค์ออกไซด์ซึ่งเป็นวัสดุกึ่งตัวนำที่สังเคราะห์ขึ้นจากกระบวนการ แอโนไดเซชันและกระบวนการสปัตเตอริง โดยศึกษาลักษณะพื้นผิวด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ ส่องกราดความละเอียดสูง (Field emission scanning electron microscope, FESEM) และ องค์ประกอบของธาตุด้วยโหมด EDS (Energy-dispersive X-ray Spectrometer, EDS) วิเคราะห์ ความขรุขระด้วยกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม (Atomic force microscope, AFM) ศึกษาความหนา ด้วยเครื่องวัดความหนาฟิล์มด้วยแสง (Optical profiler) วิเคราะห์ความเป็นผลึกหรือเฟสของ ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ดิฟแฟรคโทมิเตอร์ (X-ray diffractometer, XRD) วิเคราะห์ขนิด และสถานะทางเคมีของธาตุที่เป็นองค์ประกอบที่เกิดบนพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยเครื่องวิเคราะห์ขนิด (X-ray Photoelectron Spectroscopy, XPS) วิเคราะห์การตอบสนองของปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีแสง (Photoelectrochemistry) ด้วยการวัดความหนาแน่นของกระแส (Photocurrent density) และ

10

วิเคราะห์การดูดกลืนแสงของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยเครื่องตรวจวัดสารด้วยการดูดกลืนแสง (UV-VIS Spectrophotometer) เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนในการเลือกตัวแทนของตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์เพื่อ นำไปใช้วัดซีโอดี รายละเอียดเครื่องมือวิเคราะห์ดังภาคผนวก ก จากนั้นเป็นการศึกษาการใช้ กระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสในการวัดค่าซีโอดีโดยใช้ซิงค์ออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (COD<sub>PEC</sub>) โดยศึกษาเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์หาค่าซีโอดีก้วยวิธีมาตรฐานไดโครเมต (COD<sub>G</sub>) แบบ Closed Reflux ดังภาคผนวก ข.1 และใช้ทดลองกับสารอินทรีย์ที่ให้ค่าซีโอดีในเชิงทฤษฎี ได้แก่ กลูโคส (D-glucose) และโพแทสเซียมไฮโดรเจนพลาเลต (KHP) ที่ความเข้มข้นไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร เพื่อ ตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำและความเสถียรของวิธีการหาค่าซีโอดีด้วยกระบวนการ โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส และทำการศึกษาลักษณะทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลงไปของซิงค์ออกไซด์หลัง การนำไปใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการวัดซีโอดี รวมถึงการวิเคราะห์หาซิงค์และทองแดงในตัวอย่างน้ำที่ ทำการวัดซีโอดีด้วยเครื่อง ICP-MS เพื่อตรวจสอบความเสถียรของตัวเร่งปฏิริยาที่นำมาใช้ใน กระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะลูซิส

### 4.2.1 สังเคราะห์ซิงค์ออกไซด์ด้วยก<mark>ระบวนก</mark>ารแอโนไดเซชัน

การทดลองในเบื้องต้น ได้ทำกา<mark>ร</mark>สังเคร<mark>า</mark>ะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์โดยนำ แผ่นซิงค์ ้บริสุทธิ์ 99.98% มีความหนา 0.25 มิลลิเมต<mark>ร</mark> ตัดให้<mark>ม</mark>ีขนาดกว้าง 1 เซนติเมตร ยาว 4 เซนติเมตร ้จากนั้นนำไปล้างด้วยเครื่องอัลตราโซนิค (U<mark>ltra</mark>sonic) 2 <mark>ขั้น</mark>ตอน คือล้างด้วยอะซีโตน (Acetone) และ ้น้ำปราศจากไอออน (Deionized water, DI) ขั้นตอนละ 15 นาทีตามลำดับ สุดท้ายนำไปเป่าให้แห้ง ้ด้วยก๊าซไนโตรเจน แล้วจะได้ฐานรองรั<mark>บสำ</mark>หรับนำไปสังเครา<mark>ะห์</mark>ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยกระบวนการแอโน ้ ไดเซชัน ดังรูปที่ 4.25 ค-1 โดยที่ฐาน<mark>รอง</mark>รับที่ได้นั้นจะถูกนำมา<mark>เป็น</mark>ขั้วไฟฟ้าใช้งานต่อเข้ากับขั้วบวกของ แหล่งจ่ายไฟฟ้า และใช้แพลทินัมเป็นขั้วไฟฟ้าร่วมต่อเข้ากับขั้วลบของแหล่งจ่ายไฟฟ้า โดยจุ่มขั้วไฟฟ้า ้ทั้งสองในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ (Electrolyte) แอมโมเนียมฟลูออไรด์ (NH₄F) 0.2 โมลาร์ ศึกษา ้สภาวะที่ใช้ในการแอโนไดซ์ที่แตกต่างกัน โดยจ่ายความต่างศักย์ 1 3 5 10 และ 20 โวลต์ เป็นเวลา 5 10 และ 30 นาที ลักษณะ<mark>ของกระบวนการแอโนไดเซชันที่เกิดขึ้น เป็</mark>นดังรูปที่4.25ก และ 4.25ข ้จากรูปจะเห็นได้ว่า เมื่อเริ่มทำ<mark>การแอโนไดซ์สารละลายอิเล็กโทรไลต์จะ</mark>มีลักษณะใส แต่เมื่อระยะเวลา ้ ผ่านไปจะเริ่มมีความขุ่นเกิดขึ้นเนื่องจา<mark>กแผ่นซิงค์ถูกกัดกร่อนด้วยส</mark>ารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่มีฟลูออไรด์เป็น ้องค์ประกอบ จากกนั้นออกซิเจนในน้ำจะเกิดการรวมตัวกับซิงค์ที่ขั้วไฟฟ้าใช้งานทำให้ได้ตัวเร่งปฏิกิริยา ซิงค์ออกไซด์ ดังรูปที่ 4.25 ค-2 ซึ่งสามารถอธิบายกลไกการเกิดปฏิกิริยาได้ดังสมการที่ 4.25 ถึง 4.6 (He et al., 2010) หลังจากการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาแล้วเสร็จจะถูกนำไปล้างให้สะอาดด้วยน้ำ DI เป่าให้แห้งด้วยก๊าซไนโตรเจน เพื่อไม่ให้เกิดออกไซด์อื่น ๆ บนพื้นผิวหลังการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา แต่อย่างไรก็ตาม การจ่ายความต่างศักย์ที่สูงเกินไป (20 โวลต์) ในระยะเวลาเพียง 5 นาที ทำให้ สารละลายอิเล็กโทรไลต์เกิดความร้อนและเดือด ส่งผลให้แผ่นซิงค์ละลายจนเสียรูป ้ดังรูปที่ 4.25 ค-3 ในลำดับถัดไปจึงทำการศึกษาผลของการจ่ายความต่างศักย์โดยที่จ่ายความต่างศักย์ ในกระบวนการแอโนไดซ์ไม่เกิน 10 โวลต์



รูปที่4.25 ลักษณะการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ด้วยกระบวนการแอโนไดเซชัน ก) เมื่อเริ่มทำการแอโนไดซ์ ข) เมื่อทำการแอโนไซด์ผ่านไประยะเวลาหนึ่ง ค-1) ฐานรองรับก่อนแอโนไดซ์ ค-2) ตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ที่ได้จากกระบวนการ แอโนไดเซชัน ค-3) ตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ที่จ่ายศักย์ไฟฟ้า 20 โวลต์

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่ขั้วแอโนดหรือขั้วไฟฟ้าใช้งาน  

$$HF \rightarrow H^+ + F^-$$
 (4.1)  
 $H_2O \rightarrow H^+ + OH^-$  (4.2)

ภายใต้สนามไฟฟ้าจะเกิดการเคลื่อนที่ของโปรตอน (H<sup>+</sup>) ไปยังขั้วแคโทด และเกิดเป็นก๊าซไฮโดรเจน ดัง สมการที่ 4.3 ส่วนฟลูออไรด์ (F<sup>-</sup>) และไฮดรอกไซด์ (OH<sup>-</sup>) จะเคลื่อนที่ไปยังขั้วแอโนด แล้วกัดกร่อน พื้นผิวซิงค์และเมื่อเพิ่มระยะเวลาในการแอโนไดซ์ ก็จะพบซิงค์ละลายอยู่ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์มาก ขึ้น

$2H^++2e^- \rightarrow H_2$	(Reduction)	(4.3)

 $Zn \rightarrow Zn^{2+}+2e^{-}$  ...... (Oxidation) (4.4)

นอกจากนั้นไฮดรอกไซด์จะเกิดการสูญเสียอิเล็กตรอนดังสมการที่ 4.5 เนื่องจากมีศักย์ไฟฟ้าต่ำกว่า ฟลูออไรด์ มีออกซิเจน (O2) เกิดขึ้น แล้วเกิดการรวมตัวกันกับซิงค์ที่ขั้วแอโนดเกิดเป็นซิงค์ออกไซด์

$$4OH^{-} \longrightarrow 2H_2O + 2O + 4e^{-} \tag{4.5}$$

#### ศึกษาคุณสมบัติของซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการแอโนไดเซชัน 4.2.2 4.2.2.1 ศึกษาคุณลักษณะพื้นผิวของซิงค์ออกไซด์ด้วย FESEM

จากการทดลองสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ด้วยกระบวนการแอโนไดเซ ซัน แล้วนำมาทำการศึกษาผลของความต่างศักย์ และเวลาที่ใช้ในการสังเคราะห์แผ่นซิงค์ที่มีต่อลักษณะ ้พื้นผิวของซิงค์ออกไซด์ด้วย FESEM ได้ผลแสดงดังรูปที่ 4.26 เมื่อทำการแอโนไดซ์แผ่นซิงค์ใน แอมโมเนียมฟลูออไรด์ 0.2 โมลาร์ ความต่างศักย์คงที่ 1 โวลต์ และทำการแอโนไดซ์ที่ระยะเวลาต่างกัน พบว่า ที่ความต่างศักย์ 1 โวลต์ ลักษณะสัณฐานวิ<mark>ทย</mark>าของพื้นผิวซิงค์ออกไซด์จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมขนม เปียกปูน (rhombic shape) ดังรูปที่ 4.26-ก ถึง 4.26<mark>-ค</mark> โดยที่ระยะเวลา 5 นาที พื้นผิวซิงค์ออกไซด์จะเริ่มมี ้ลักษณะทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเกิดขึ้นเพียงเ<mark>ล็กน้อย</mark>และอยู่อย่างกระจัดกระจาย แต่เมื่อระยะเวลา เพิ่มมากขึ้น คือ 10 นาที และ 30 นาที จะเห็นได้ว่าจำนวนของลักษณะทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีมากขึ้น ตามระยะเวลา ที่ความต่างศักย์ 3 โวลต์ ระยะเวลา 5 นาที ลักษณะสัณฐานวิทยาของพื้นผิ้วซิงค์ออก ์ ไซด์เป็นทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่มีขนาดเ<mark>ล็ก</mark> ดังรูปที่ <mark>4.2</mark>6-ง มีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อระยะเวลา 10 นาที ้ดังรูปที่ 4.26-จ และมีขนาดใหญ่และชัดเจน<mark>ขึ้น</mark>เมื่อระยะเว<mark>ลา</mark> 30 นาที ดังรูปที่ 4.26-ฉ ความต่างศักย์ 5 ้โวลต์ ระยะเวลา 5 นาที ลักษณะสัณฐา<mark>นวิท</mark>ยาของพื้นผิวซิงค์<mark>ออก</mark>ไซด์เริ่มเกิดเป็นทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียก ู ปูนที่ยังหลอมติดเป็นเนื้อเดียวกัน ดังรู<mark>ปที่</mark> 4.26-ช แต่เมื่อระยะเว<mark>ลา</mark>มากขึ้นลักษณะทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียก ู้ปูนจะมีขนาดใหญ่ขึ้น ดังรูปที่ 4.26<mark>-</mark>ซ และ 4.26-ฌ แต่ความต่างศั<mark>ก</mark>ย์ 10 โวลต์ ระยะเวลา 5 นาที 10 ้นาที และ 30 นาที จะมีรอยแย<mark>ก</mark>เกิดขึ้นที่พื้นผิวซิงค์ออกไซด์ ดังรูปที่ 4.26-ญ 4.26-ฏ และ 4.26-ฏ นอกจากนั้น รูปที่ 4.26-ก ถึง 4<mark>.26-</mark>ฏ ยั<mark>งแสดงให้เห็นว่า ที่ระยะเวล</mark>าใน<mark>การแ</mark>อโนไดซ์เท่ากัน เมื่อมีการเพิ่ม ้ความต่างศักย์เป็น 3 โวลต์ 5 <mark>โวลต์ ลักษณะพื้นผิวซิงค์ออกไซด์จะมีลักษณ</mark>ะทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่ ้ มีความชัดเจนและจำนวนมากขึ้<mark>นตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตามการจ่ายคว</mark>ามต่างศักย์ที่สูง (10 โวลต์) ก็ ้จะทำให้พื้นผิวซิงค์ออกไซด์มีลักษณ<mark>ะที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีออกไซด์</mark>เกิดขึ้นหนาและเกิดรอยแยกขึ้นที่ บนพื้นผิวของซิงค์ออกไซด์ อายาลัยเทคโนโลยีสรัง

(4.6)



รูปที่ 4.26 ภาพถ่าย FESEM ของ ZnO ที่ผ่านการแอโนไดซ์ใน NH₄F 0.2 โมลาร์ ที่อุณหภูมิห้อง โดยเปลี่ยนแปลงความต่างศักย์ และระยะเวลาที่ใช้ในการแอโนไดซ์ ก) 1 โวลต์ 5 นาที ข) 1 โวลต์ 10 นาที ค) 1 โวลต์ 30 นาที ง) 3โวลต์ 5 นาที จ) 3 โวลต์ 10 นาที ฉ) 3 โวลต์ 30 นาที ช) 5 โวลต์ 5 นาที ซ) 5 โวลต์ 10 นาที ฌ) 5 โวลต์ 30 นาที ญ) 10 โวลต์ 5 นาที ฎ) 10 โวลต์ 10 นาที และ ฏ) 10 โวลต์ 30 นาที

หลังจากที่ทำการศึกษาผลของความต่างศักย์และเวลาที่ใช้ในการสังเคราะห์ แผ่นชิงค์ที่มีต่อลักษณะพื้นผิวของซิงค์ออกไซด์ด้วย FESEM แล้ว การทดสอบความแข็งแรงและคงทนของ ตัวเร่งปฏิกิริยาก็มีความสำคัญเช่นกัน ดังนั้น จึงได้ทำการทดสอบโดยนำตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ ที่สังเคราะห์ จ่ายความต่างศักย์คงที่ 3 โวลต์ เป็นเวลา 5 นาที 10 นาที และ 30 นาที ไปทำการเขย่าใน น้ำ DI ด้วยเครื่องอัลตราโซนิคความถี่ 40 กิโลเฮิรตซ์ (KHz) เป็นเวลา 15 นาที พบว่า น้ำ DI มีความขุ่น และผิวหน้าของซิงค์ออกไซด์ถูกล้างหลุดออกไปตามขนาดของโครงสร้างรูปทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน เหลือ เพียงพื้นผิวที่เป็นธรรมชาติของวัสดุชิงค์ ดังรูปที่ 4.27-ก ถึง 4.27-คและเมื่อนำผงตะกอนในน้ำ DI ไปทำให้ แห้งแล้วถ่ายภาพด้วย FESEM ก็พบว่าเป็นซิงค์ออกไซด์ ดังรูปที่ 4.28



รูปที่ 4.27 ภาพถ่าย FESEM เมื่อทำการแอโนไดซ์ซิงค์ออกไซด์ในแอมโมเนียมฟลูออไรด์ 0.2 โมลาร์ ความต่างศักย์คงที่ 3 โวลต์ ก) 5 นาที ข) 10 นาที และ ค) 30 นาที หลังการล้างด้วย เครื่องอัลตราโซนิค



รูปที่ 4.28 ผงตะกอนซิงค์ออกไซด์ในน้ำ DI เมื่อผ่านการอัลตราโซนิค

จากนั้นนำตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์แล้วไปอบที่อุณหภูมิ

แตกต่างกัน เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิที่อบหลังจากการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา พบว่า ก<sup>่</sup>ารอบ<sup>ท</sup>ี่ 70 องศาเซลเซียส และ 250 องศาเซลเซียส แผ่นซิงค์ออกไซด์ยังคงรูปเดิม แต่ที่ 450 องศาเซลเซียส นั้นทำให้แผ่นซิงค์ออกไซด์เกิดการบิดงอเสียรูป ดังรูปที่ 4.29-ก ถึง 4.29-ค จึงไม่นำไปทำการศึกษาด้วย FESEM



รูปที่ 4.29 ซิงค์ออกไซด์หลังอ<mark>บที่อ</mark>ุณหภูมิ ก) 70 องศา<mark>เซล</mark>เซียส ข) 250 องศาเซลเซียส และ ค) 450 อง<mark>ศ</mark>าเซลเซียส

ส่วนการอบด้วยอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส และ 250 องศาเซลเซียส เมื่อ ถ่ายภาพด้วย FESEM แสดงดังรูปที่ 4.30-ฆ ถึง 4.30-ซ พบว่าไม่ได้ทำให้ลักษณะพื้นผิวของซิงค์ออกไซด์ มีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม<mark>ที่ไม่มีการอบ (เปรียบเทียบกับ FESE</mark>M รูปที่ 4.26-ฉ ถึง 4.26-ฎ)





รูปที่ 4.30 ภาพถ่าย FESEM ของซิงค์ออกไซด์ที่แอโนไดซ์ในแอมโมเนียมฟลูออไรด์ 0.2 โมลาร์ ความต่างศักย์คงที่ 5 โวลต์ ง) 5 นาที จ) 10 นาที และ ฉ) 30 นาที หลังอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสและซิงค์ออกไซด์ที่แอโนไดซ์ในแอมโมเนียมฟลูออไรด์ 0.2 โมลาร์ ความ ต่างศักย์คงที่ 10 โวลต์ ช) 5 นาที ซ) 10 นาที และ ฌ) 30 นาที หลังอบที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส

จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปลักษณะพื้นผิวซิงค์ออกไซด์ที่ได้จาก การแอโนไดซ์ที่สภาวะที่แตกต่างกันได้ดังตารางที่ 4.14 และจากการพิจารณาลักษณะสัณฐานวิทยาของ ซิงค์ออกไซด์ที่สภาวะการแอโนไดซ์ที่ต่างกันจะเห็นได้ว่าเมื่อจ่ายความต่างศักย์ที่ 3 โวลต์ แนวโน้มที่ ลักษณะสัณฐานวิทยาจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่ชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อใช้ระยะเวลาในการ แอโนไดซ์ที่นานขึ้น จึงเลือกสภาวะการแอโนไดซ์ที่ 3 โวลต์เท่ากัน ที่ระยะเวลาการแอโนไดซ์ 5 นาที 10 นาที และ 30 นาที ไปทำการวิเคราะห์ความเป็นผลึกหรือเฟสของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วย XRD ต่อ และนอกจากนั้นจะเห็นได้ว่าการจ่ายความต่างที่สูงขึ้นนั้นจะทำให้ขนาดของทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมี ขนาดใหญ่ขึ้นด้วย จึงเลือกสภาวะการแอโนไดซ์ที่ความต่างศักย์ 1 โวลต์ 3 โวลต์ 5 โวลต์ และ 10 โวลต์ ระยะเวลา 30 นาทีเท่ากัน ไปศึกษาด้วย XRD เช่นกัน

สภาวะการแอโนไดซ์					
รูปที่	สารละลาย อิเล็กโทรไลต์	ความต่างศักย์ (โวลต์)	ระยะเวลา (นาที)	ขนาด (นาโนเมตร)	ลักษณะสัณฐานวิทยา
4.2-ก	NH₄F 0.2 โมลาร์	1	5	100 - 200	ทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ขนาดเล็ก
4.2-ข		1	10	500 - 600	ทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ขนาดเล็กที่หลอมติดกัน
4.2-ค		1	30	300 - 400	ทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ขนาดเล็กที่หลอมติดกัน
4.2-1		3	5	< 100	ทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ขนาดเล็ก
4.2-จ		3	10	300 - 400	ทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่ หลอมติดกัน
4.2-ฉ		3	30	200 - 700	ทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่ ชัดเจน สมบูรณ์
4.2-ช		5	5	200 - 300	ทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่ หลอมติดกัน
4.2-ซ		5	10	200 - 500	ทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่ ชัดเจน สมบูรณ์
4.2-ฌ		5	-30	300 - 500	ทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่ หลอมติดกัน
4.2-ญ		10	5	7	รอยแยกที่พื้นผิวซิงค์ออกไซด์
4.2-ฎ		10	10		รอยแยกที่พื้นผิวซิงค์ออกไซด์
4.2-ฏ		10	30	/-	รอยแยกที่พื้นผิวซิงค์ออกไซด์
4.3-4.4	ล้างด้วยน้ำ DI <mark>ในเครื่องอัลต</mark> ราโซนิกหลังการแอโนไดซ์			ซิงค์ออกไซด์ถูกล้างหลุดออก	
4.5	อบด้วยอุณหภูมิ 70 ºC และ 250 ºC หลังการแอโนไดซ์			ลักษณะไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม ที่ไม่ได้อบ	

ตารางที่ 4.14 ลักษณะสัณฐานวิทยาของซิงค์ออกไซด์ที่สภาวะการแอโนไดซ์ต่าง ๆ

<sup>7</sup>่า<sub>วักยา</sub>ลัยเทคโนโลยีสุรบั

### 4.2.2.2 วิเคราะห์ความขรุขระของซิงค์ออกไซด์ด้วย AFM

จากการศึกษาความขรุขระของตัวอย่างซิงค์ออกไซด์ที่แอโนไดซ์โดยจ่ายความ ต่างศักย์ 3 โวลต์ เป็นเวลา 30 นาที และ 60 นาที ด้วยเครื่อง AFM พบว่า มีความขรุขระ (R<sub>a</sub>) เฉลี่ยอยู่ ที่ 48.203 นาโนเมตร และ 58.745 นาโนเมตร ตามลำดับ แสดงดังรูปที่ 4.31 จากการคาดการณ์เมื่อใช้ เวลาในการแอโนไดซ์นานขึ้น ขนาดผลึกสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและมี ความหนาของซิงค์ออกไซด์มากขึ้น ส่งผลให้พื้นผิวของซิงค์ออกไซด์มีความหยาบหรือมีพื้นผิวขรุขระมาก ขึ้นด้วย



รูปที่ 4.31 ภาพถ่าย AFM ของซิงค์ออกไซด์ที่ผ่านการแอโนไดซ์ใน NH₄F 0.2 โมลาร์ ที่อุณหภูมิห้อง และความต่างศักย์ 3 โวลต์ ที่ระยะเวลา ก) 30 นาที และ ข) 60 นาที

## 4.2.2.3 วิเคราะห์โครงสร้างผลึกหรือเฟสที่เกิดบนพื้นผิวของซิงค์ออกไซด์ด้วย

### เครื่อง XRD

### จากการเลือกสภาวะการแอโนไดซ์มาวิเคราะห์ด้วย XRD เพื่อตรวจสอบว่า

ออกไซด์ที่เกิดขึ้นเป็นของซิงค์ออกไซด์ พบว่า เมื่อทำการแอโนไดซ์แผ่นซิงค์โดยใช้ความต่างศักย์คงที่ เท่ากันคือ 3 โวลต์ แต่ระยะเวลาต่างกัน คือ 5 นาที 10 นาที 30 นาที จากข้อมูล XRD จะพบเพียง รูปแบบของซิงค์ที่เป็น hexagonal phase ตามข้อมูล JCPDS card (No. 01-1238, a = 2.6591 nm, c = 4.9353 nm) จะปรากฏที่พีค 20 = 36.496° 39.134° 43.473° 54.582° 70.785° สอดคล้องกับ (002) (100) (101) (102) (110) ตามลำดับ เมื่อใช้เวลาในการแอโนไดซ์น้อย ๆ (ที่ 5 นาที) จะพบพีค ของซิงค์สูง แต่เมื่อใช้เวลาในการแอโนไดซ์มากขึ้น คือ 10 นาที และ 30 นาที พีคของซิงค์จะค่อย ๆ ลดลง และการการคาดการณ์ว่าการใช้ระยะเวลาในการแอโนไดซ์ที่นานขึ้นจะทำให้เห็นพีคของ ซิงค์ออกไซด์ที่ชัดเจนขึ้นนั้น จึงได้ทำการศึกษาเพิ่มเติม โดยเพิ่มระยะเวลาที่ใช้ในการแอโนไดซ์ คือ 60 นาที และ 120 นาที พบว่า เริ่มมีพีคของซิงค์ออกไซด์เกิดขึ้นที่ระยะเวลา 60 นาที และพีคของซิงค์ออก ไซด์สูงขึ้นที่ระยะเวลา 120 นาที ตามข้อมูล JCPDS card (No. 36-1451, a = 0.3249 nm, c = 0.5206 nm) จะปรากฏที่พีค 20 = 31.7° 34.4° 36.3° 47.5° 56.6° 62.3° 66.5° 67.9° 69.1° สอดคล้องกับ (100) (002) (101) (102) (110) (103) (200) (112) และ (201) ตามลำดับ (Lupan et al., 2008, Chen et al., 2011) ดังรูปที่ 4.32 ซึ่งจะเห็นได้ว่าที่ระยะเวลาสั้น ๆ จะไม่เห็นพีคของซิงค์อ อกไซด์ เนื่องจากการเกิดปฏิกิริยามีน้อยมาก



รูปที่ 4.32 XRD ของ ZnO ที่ผ่านการแอโนไดซ์ใน NH4F 0.2 โมลาร์ ที่อุณหภูมิห้อง ความต่างศักย์ 3 โวลต์ ที่ระยะเวลา 5 นาที 10 นาที 30 นาที 60 นาที และ 120 นาที

และเมื่อทำการแอโนไดซ์โดยจ่ายศักย์ไฟฟ้าที่ต่ำ คือ 1 โวลต์ และ 3 โวลต์ จะพบเพียงพีคของซิงค์ เท่านั้น แต่เมื่อจ่ายศักย์ไฟฟ้าที่สูงขึ้น (5 โวลต์) จะพบพีคของซิงค์และเริ่มเห็นพีคของซิงค์อออกไซด์ และพีคของซิงค์อออกไซด์สูงขึ้นเมื่อจ่ายความต่างศักย์ 10 โวลต์ ดังรูปที่ 4.33



รูปที่ 4.33 XRD ของ ZnO ที่ผ่านการแอโนไดซ์ใน NH₄F 0.2 โมลาร์ที่อุณหภูมิห้อง ความต่างศักย์ 1 โวลต์ 3 โวลต์ 5 โวลต์ และ 10 โวลต์ ที่ระยะเวลาเท่ากัน คือ 30 นาที

ข้อมูล XRD ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การจ่ายศักย์ไฟฟ้าสูงขึ้น และการใช้ ระยะเวลาที่นานขึ้นจะทำให้เกิดซิงค์ออกไซด์มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามจากภาพถ่าย FESEM จะเห็นได้ ว่าเมื่อจ่ายความต่างศักย์ที่สูงขึ้น คือมากกว่า 3 โวลต์ ทำให้ลักษณะสัณฐานวิทยาของซิงค์ออกไซด์เริ่ม เปลี่ยนไปไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน จึงไม่ทำการศึกษาต่อในสภาวะการแอโนไดซ์ที่จ่ายความต่าง ศักย์ 5 โวลต์ และ 10 โวลต์

### 4.2.2.4 วิเคราะห์การดูดกลื่นแสงของซิงค์ออกไซด์ด้วยเครื่อง UV-VIS

### spectrophotometer

จากการวิเคราะห์การดูดกลืนแสงของซิงค์ออกไซด์ด้วยเครื่อง UV-VIS spectrophotometer โดยได้ทำการวัดการดูดกลืนแสงของตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่เป็นฐานรองรับ นั่นคือ ซิงค์และซิงค์ที่ผ่านการขัดด้วยกระดาษทราย และอีกกลุ่มตัวอย่างคือวัสดุซิงค์ที่ผ่านการ แอโนไดซ์ที่ความต่างศักย์คงที่ 3 โวลต์ เท่ากัน แต่แตกต่างกันที่ระยะเวลาที่ใช้ในการแอโนไดซ์ นั่นคือ 5 นาที 10 นาที 30 นาที 60 นาที และ 120 นาที จากรูปที่ 4.34 จะเห็นได้ว่า แผ่นซิงค์ที่ผ่านการขัดด้วย กระดาษทรายจะดูดกลืนแสงทั้งช่วงยูวี (UV) และวิสิเบิล (Visible) และการดูดกลืนแสงมากกว่าแผ่นซิงค์ที่ ไม่ผ่านการขัดด้วยกระดาษทราย และการดูดกลืนแสงลดลงเมื่อผ่านการแอโนไดซ์ที่ระยะเวลามากขึ้น ซึ่ง การใช้ระยะเวลาในการแอโนไดซ์นาน ทำให้ผลึกสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีขนาดใหญ่กว่าการใช้ระยะเวลา สั้น จึงเกิดการสะท้อนแสงได้มากกว่าผลึกสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนขนานเล็ก เป็นผลทำให้การดูดกลืนแสงน้อย กว่าการแอโนไดซ์โดยใช้ระยะเวลาสั้น ๆ และเนื่องจากการแอโนไดซ์ที่ระยะเวลา 120 นาที นั้นทำให้ แผ่นซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ขึ้นนั้นมีลักษณะของการถูกกัดกร่อนและขาด ทำให้แผ่นซิงค์มีขนาดเล็ก ลงจากเดิม ซึ่งจะส่งผลต่อการเกิดปฏิกิริยาบนแผ่นซิงค์ออกไซด์ที่จะนำไปใช้งานต่อไป จึงไม่นำไป ทำการศึกษาต่อสำหรับสภาวะนี้



### รูปที่ 4.34 UV-VIS ของซิงค์ที่ผ่านการขัด และซิงค์ออกไซด์ที่ผ่านการแอโนไดซ์ที่เวลาต่างกัน

4.2.2.5 วิเคราะห์อิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นในรูปของความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า (Photocurrent density) ของซิงค์ออกไซด์ด้วยเครื่อง Potentiostat

จากการวิเคราะห์ Photocurrent density เพื่อวัดอิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นในรูป ของกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการฉายแสงผ่านตัวเร่งปฏิกิริยา ZnO ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบทาง เคมีไฟฟ้า (Potentiostat, Mettrohm Autolab) โดยวิเคราะห์ซิงค์อออกไซด์ที่ผ่านการแอโนไดซ์โดย เปรียบเทียบการฉายแสงและไม่ฉายแสงไปยังตัวเร่งปฏิกิริยา พบว่า Photocurrent density ที่ความต่างศักย์ 0.4 โวลต์ ของตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีการฉายแสงเท่ากับ 105.976 มิลลิแอมแปร์ต่อตารางเซนติเมตร และ ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ไม่ฉายแสงเท่ากับ 65.074 มิลลิแอมแปร์ต่อตารางเซนติเมตร ซึ่งจะเห็นได้ว่า การฉายแสงให้ Photocurrent density ที่สูงกว่าการไม่ฉายแสง แสดงดังรูปที่ 4.35



รูปที่ 4.35 อิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นในรูปของ Photocurrent density ของ ZnO ที่ผ่านการแอโนไดซ์ จ่ายความต่างศักย์คงที่ 3 โวลต์ ระยะเวลา 60 นาที เปรียบเทียบ ZnO ที่ผ่านการฉาย แสง และไม่ผ่านการฉายแสง

และเมื่อทำการศึกษาผลของระยะเวลา โดยจ่ายความต่างศักย์คงที่ 3 โวลต์

เท่ากัน ที่ระยะเวลาที่ใช้ในการแอโนไดซ์แตกต่างกัน คือ 5 นาที 10 นาที 30 นาที 60 นาที พบว่าการใช้ ระยะเวลาในการแอโนไดซ์ที่นานขึ้นทำให้เกิดอิเล็กตรอนมากขึ้น ซึ่ง Photocurrent density เท่ากับ 55.481 188.951 189.535 และ 201.333 มิลลิแอมแปร์ต่อตารางเซนติเมตร ตามลำดับ แสดงดัง รูปที่ 4.36



รูปที่ 4.36 อิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นใ<mark>นรูปของ Photocurrent density</mark> ของ ZnO ที่ผ่านการแอโนไดซ์ จ่ายความต่างศักย์คงที่ 3 โวลต์ เท่ากัน ที่ระยะเวลาที่ใช้ในการแอโนไดซ์แตกต่างกัน คือ 5 นาที 10 นาที 30 นาที และ 60 นาที จากการคาดการณ์ว่าการแอโนไดซ์โดยใช้ความต่างศักย์เพิ่มขึ้นที่ระยะเวลา เท่ากันนั้น จะทำให้ อิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นในรูปของกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น จึงได้ทำการวัด Photocurrent density ในสภาวะการแอโนไดซ์ที่จ่ายความต่างศักย์ 1 โวลต์ 3 โวลต์ 5 โวลต์ และ 10 โวลต์ ระยะเวลา 30 นาทีเท่ากันด้วย และพบว่าผลการทดลองที่เกิดขึ้นเป็นไปตามการคาดการณ์ Photocurrent density เท่ากับ 71.564 189.535 198.019 และ 223.185 มิลลิแอมแปร์ต่อตารางเซนติเมตร ตามลำดับ ซึ่งแสดงดังรูปที่ 4.37



รูปที่ 4.37 อิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นในรูปของ Photocurrent density ของ ZnO ที่ผ่านการแอโนไดซ์ จ่ายความต่างศักย์คงที่ 1 โวลต์ 3 โวลต์ 5 โวลต์ และ 10 โวลต์ ที่ระยะเวลาที่ใช้ใน การแอโนไดซ์เท่ากัน คือ 30 นาที

และจากการศึกษาผลของชนิดของแหล่งกำเนิดแสง โดยทำการเปรียบเทียบ แหล่งกำเนิดแสงที่ฉายไปยังตัวเร่งปฏิกิริยา คือ แหล่งกำเนิดแสงยูวี และแหล่งกำเนิดแสงวิสิเบิล พบว่า แผ่นซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ขึ้นนั้นตอบสนองต่อแสงยูวีได้ดีกว่าวิสิเบิล Photocurrent density เท่ากับ 357.049 และ 201.333 มิลลิแอมแปร์ต่อตารางเซนติเมตร ตามลำดับ แสดงดังรูปที่ 4.38



รูปที่ 4.38 อิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นในรูปของ Photocurrent density ของ ZnO ที่ผ่านการแอโนไดซ์ จ่ายความต่างศักย์คงที่ 3 โวลต์ ระยะเวลา 60 นาที โดยเปรียบเทียบ ZnO ที่ผ่านการ ฉายแสงจากแหล่งกำเนิดแสงยูวี และ ZnO ที่ผ่านการฉายแสงจากแหล่งกำเนิดแสงวิสิเบิล

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าซิงค์ออกไซด์ที่ผ่านที่ผ่านการแอโน ไดซ์โดยจ่ายความต่างศักย์คงที่ 3 โวลต์ ระยะเวลา 60 นาที จะถูกเลือกนำไปใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาใน การวิเคราะห์หาซีโอดีในน้ำเสียต่อไป เนื่องจากมีลักษณะสัณฐานวิทยารูปทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่ ขัดเจน สม่ำเสมอ ที่สามารถวิเคราะห์ได้จาก FESEM มีพีคที่แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างผลึกหรือเฟสเป็น ซิงค์ออกไซด์ สามารถวิเคราะห์ได้จาก XRD สามารถตอบสนองได้ทั้งแหล่งกำเนิดแสงยูวีและ วิสิเบิล และท้ายที่สุดมีอิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นในรูปของ Photocurrent density มากที่สุดด้วย
#### 4.2.2.6 ศึกษาการตอบสนองต่อแสงของตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์

ทำการศึกษาการตอบสนองต่อแสง ด้วยเครื่องโพเทนซิโอสแตท (Potentiostat) โดยฉายแสงจากหลอดยูวี (UV-LED) ขนาด 10 วัตต์ ความยาวคลื่น 365 นาโนเมตร และจ่ายความต่างศักย์คงที่ที่ 0.5 โวลต์ ไปยังตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการ แอโนไดเซชัน ซึ่งในช่วงระยะเวลาแรกของการทดลองได้ทำการปิดสวิตซ์ไฟ พบว่า กระแสไฟฟ้าที่วัดได้ มีค่าต่ำ แต่เมื่อทำการเปิดสวิตซ์ไฟกระแสไฟฟ้าก็จะมีค่าสูงขึ้นเนื่องจากแสงเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้เกิด การแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนบนพื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยาได้ดีขึ้น ดังรูปที่ 4.39 แต่จะเห็นได้ว่ากระแสไฟฟ้าที่ วัดได้จะมีค่าสูงขึ้นเรื่อย ๆ จึงสันนิษฐานว่าอาจเกิดเนื่องมาจากตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ ขึ้นด้วยกระบวนการแอโนไดเซชันนั้นมีความไม่เสถียร



รูปที่ 4.39 การตอบสนองต่อแสงของซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการแอโนไดเซชัน ในสารละลายอิเล็กโทรไสต์ Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 0.1 โมลาร์ จ่ายความต่างศักย์คงที่ 0.5 โวลต์

# 4.2.3 ศึกษาการใช้กระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสในการวัดค่าซีโอดี (COD<sub>PEC</sub>) โดยใช้ซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์จากกระบวนการแอโนไดซเซชันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา 4.2.3.1 วัดค่าซีโอดีด้วยเครื่องวัดที่สร้างขึ้น

เมื่อทำการวัดค่าซีโอดีด้วยวิธีการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสโดยใช้ ซิงค์ออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา จากเครื่องมือที่สร้างขึ้นดังรูปที่ 4.40 ที่เกิดจากการนำกระบวนการ โฟโตคะตะไลซิสมาประยุกต์เข้ากับเซลล์ไฟฟ้าแบบ 3 ขั้ว โดยนำตัวแทนของตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ ที่ได้จากกระบวนการแอโนไดเซชันมาต่อเป็นขั้วไฟฟ้าใช้งาน (Working electrode) ใช้แพลทินัม (Pt) เป็นขั้วไฟฟ้าร่วม (Counter electrode) และใช้ซิลเวอร์/ซิลเวอร์คลอไรด์ (Ag/AgCl) เป็นขั้วไฟฟ้า อ้างอิง (Reference electrode) กล่าวคือ เมื่อมีการให้พลังงานจากแสงยูวี (UV) แก่ตัวเร่งปฏิกิริยา ทำ ให้เกิดการกระตุ้นอิเล็กตรอนจนเกิดเป็นเรดิคอลที่มีความสามารถในการออกซิไดซ์สารอินทรีย์ได้ และมี การจ่ายความต่างศักย์ให้กับขั้วไฟฟ้าใช้งานด้วยในขณะฉายแสง จะช่วยทำให้การออกซิไดซ์สารอินทรีย์ เป็นไปอย่างสมบูรณ์มากขึ้น



รูปที่ 4.40 ชุดการทดลองการหาค่าซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส

หลักการของการหาค่าซีโอดีจากกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส คือ

เมื่อทำการจ่ายความต่างศักย์ไฟฟ้าและทำการฉายแสงไปยังตัวเร่งปฏิกิริยา แล้ววัดกระแสไฟฟ้าช่วง ระยะเวลาหนึ่งๆ จะพบว่า I<sub>(blank)</sub> จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นจนเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือเสถียรภาพ และ I<sub>(total)</sub> จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นเมื่อเกิดการออกซิไดซ์สารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำ และจะค่อย ๆ ลดลงจนถึงระดับเดียวกัน กับ I<sub>(blank)</sub> เมื่อสารอินทรีย์ถูกออกซิไดซ์จนหมด โดยที่ I<sub>(blank)</sub> คือค่ากระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการ ออกซิเดชันของน้ำที่ไม่มีสารอินทรีย์ I<sub>(total)</sub> คือค่ากระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการออกซิเดชันของน้ำที่มี สารอินทรีย์ ซึ่งในการทดลองได้ทำการวัดการตอบสนองของกระแสไฟฟ้าจากกระบวนการ โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสของซีโอดีจากสารละลายมาตรฐานกลูโคส (D-glucose) ที่ความเข้มข้น 10 100 และ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ละความเข้มข้นของซีโอดี กลูโคสจะถูกผสมเข้ากับสารอิเล็กโทรไลต์โซเดียม ซัลเฟต (Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) 0.1 โมลาร์ ใช้น้ำตัวอย่างปริมาณ 50 มิลลิลิตร และจ่ายความต่างศักย์คงที่ 0.5 โวลต์ ซึ่งผลการทดลองแสดงดังรูปที่ 4.41



รูปที่ 4.41 การตอบสนองของกระแสไฟฟ้าจากกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส ความเข้มข้นซีโอดี 10 มิลลิกรัมต่อลิตร 100 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

จากการทดลองจะเห็นว่า I<sub>ph (total)</sub> ของน้ำตัวอย่างที่มีสารอินทรีย์ไม่สามารถ ลดลงจนถึงระดับเดียวกันกับ I<sub>ph (blank)</sub> ในระยะเวลา 120 วินาที นั่นหมายถึงสารอินทรีย์ไม่ถูกออกซิไดซ์ ได้จนหมด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปริมาณตัวอย่างมีผลต่อการทดลอง จึงจำเป็นต้องทำการทดลอง การแปรผันปริมาณน้ำตัวอย่างในการวัดซีโอดีครั้งนี้ด้วย แต่เนื่องจากข้อจำกัดของอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นนั้น ไม่สามารถแปรผันปริมาณน้ำได้ จึงจะทำการสร้างถังปฏิกรณ์ขึ้นใหม่เพื่อให้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ โดย มีลักษณะ ดังรูปที่ 4.42



ในการหาค่าซีโอดีด้วยวิธีการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสในเบื้องต้นนั้น ได้ ทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการวัดค่าซีโอดี ได้แก่ ความเข้มข้นของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ และความ ต่างศักย์ที่จ่ายให้กับตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์



รูปที่ 4.43 การตอบสนองของกระแสไฟฟ้าจากกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสของซีโอดี ความเข้มข้นของสารละลายอิเล็กโตรไลต์ Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ก) 0.1 โมลาร์ ข) 0.5 โมลาร์ ค) 1.0 โมลาร์ ภายหลังจากที่ทำการเปลี่ยนแปลงถังปฏิกรณ์แล้ว ได้ลดปริมาณน้ำตัวอย่างลง โดยใช้ปริมาณน้ำตัวอย่าง 3 มิลลิลิตร แล้วแปรผันความเข้มข้นของสารอิเล็กโทรไลต์ที่ความเข้มข้นต่างกัน คือ 0.1 โมลาร์ 0.5 โมลาร์ และ 1 โมลาร์ พบว่า ที่ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ กระแสไฟฟ้าจากการวัดแบลงค์ลดลง เรื่อย ๆ เมื่อระยะเวลาผ่านไป และกระแสที่วัดได้อยู่ในช่วง 300-350 มิลลิแอมแปร์ (mA) แต่เมื่อเพิ่มความ เข้มข้นของสารอิเล็กโทรไลต์ การตอบสนองของกระแสไฟฟ้าที่วัดได้ลดลง โดยที่ความเข้มข้น 0.5 โมลาร์ และ 1.0 โมลาร์ กระแสที่วัดได้อยู่ในช่วง 200-250 มิลลิแอมแปร์ และ 150-200 มิลลิแอมแปร์ ตามลำดับ แต่ อย่างไรก็ตามกระแสไฟฟ้าที่วัดซ้ำในแต่ละความเข้มข้นยังคงไม่ใกล้เคียงกัน ซึ่งแสดงดังรูปที่ 4.43 และเมื่อทำ การแปรผันความต่างศักย์ที่จ่าย คือ 0.5 โวลต์ 1 โวลต์ และ 1.5 โวลต์ พบว่า การจ่ายความต่างศักย์ที่มากขึ้น ทำให้กระแสไฟฟ้าที่วัดได้สูงขึ้น ดังรูปที่ ก และ ข แต่หากทำการจ่ายความต่างศักย์ที่สูงเกินไปจนเกิดการ เสียหายของตัวเร่งปฏิกิริยา จะทำให้กระแสที่ได้ไม่คงที่ แสดงดังรูปที่ 4.44



รูปที่ 4.44 การตอบสนองของกระแสไฟฟ้าจากกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสของซีโอดี จ่ายความต่างศักย์คงที่ ก) 0.5 โวลต์ ข) 1 โวลต์ และ ค) 1.5 โวลต์

#### 4.2.3.2 วัดค่าซีโอดีด้วยเครื่องโพเทนซิโอสแตท (Potentiostat)

จากการทดลองในข้างต้น จะเห็นได้ว่า กระแสของการวัดค่าซีโอดีที่ความ เข้มข้นเดียวกันในแต่ละซ้ำที่ทำการตรวจวัดนั้นไม่มีค่าใกล้เคียงกัน และเพื่อตรวจสอบดูว่าผลจากการวัด ที่ได้ไม่ได้เกิดจากการใช้การเครื่องมือที่สร้างขึ้นเอง จึงทดลองใช้เครื่องโพเทนชิโอสแตทในการ วัดค่ากระแสจากกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสแทน เมื่อทำการวัดความเข้มข้นซีโอดีของ กลูโคส 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเข้มข้นของสารอิเล็กโทรไลต์ที่ใช้คือ Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 0.1 โมลาร์ จ่ายความ ต่างศักย์คงที่ 0.5 โวลต์ ใช้ปริมาตรน้ำ 3 มิลลิลิตร ระยะเวลาที่ใช้ในการหาค่าซีโอดีเท่ากับ 3 นาที ผลการวัดกระแสที่ได้เป็นดังรูปที่ 4.45 จากการทดลองจะเห็นว่า I<sub>(total)</sub> ของน้ำตัวอย่างที่มีสารอินทรีย์ ไม่สามารถลดลงจนถึงระดับเดียวกันกับ I<sub>(blank</sub>) ในระยะเวลา 120 วินาที นั่นหมายถึงสารอินทรีย์ไม่ถูก ออกซิไดซ์ได้จนหมด และเมื่อทำการวัดความเข้มข้นของกลูโคสโดยใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นเป็น 5 นาที ก็ยัง พบว่า I<sub>(total)</sub> ของน้ำตัวอย่างที่มีสารอินทรีย์ไม่สามารถลดลงจนถึงระดับเดียวกันกับ I<sub>(blank)</sub> นอกจากนั้น จะเห็นได้ว่า ชุดข้อมูลกระแสที่วัดได้มีค่าแกว่ง ไม่คงที่และมีแนวโน้มที่จะสูงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อใช้ ระยะเวลาในการวัดซีโอดีมากขึ้น เนื่องมาจากความไม่เสถียรของซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีแอโน ไดเซชัน ดังรูปที่ 4.46



รูปที่ 4.45 การตอบสนองของกระแสไฟฟ้าจากกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส วัดความเข้มข้นซีโอดีของกลูโคส 50 มิลลิกรัมต่อลิตร สารอิเล็กโทรไลต์ Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 0.1 โมลาร์ ปริมาตรน้ำ 3 มิลลิลิตร จ่ายความต่างศักย์คงที่ 0.5 โวลต์ วัดเป็นระยะเวลา ก) 2 นาที ข) 3 นาที

จากข้อมูลการวัดซีโอดีที่ผ่านมา พบว่า กระแสไฟฟ้าที่ทำการวัดด้วย กระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสมีค่าไม่คงที่ เนื่องจากตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ขึ้น ด้วยกระบวนการแอโนไดเซชันนั้นมีการหลุดลอกปะปนกับน้ำเมื่อมีการจ่ายความต่างศักย์ไฟฟ้า ดังรูปที่ 4.21 และการใช้ซิงค์ออกไซด์ที่มีซิงค์เป็นฐานรองรับ (substrate) กับสารละลายอิเล็กโตรไลต์ โซเดียมซัลเฟตอาจทำให้ไออนลบจากซัลเฟต (SO4<sup>-</sup>) ละลายซิงค์ให้หลุดออก (Farrukh, Thong et al., 2012) ซิงค์ออกไซด์จึงมีความไม่เสถียร ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดสอบความแข็งแรงและคงทนของตัวเร่ง ปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ด้วยเครื่องอัลตราโซนิคที่ผ่านมา จึงทำการเปลี่ยนวิธีการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา เป็นกระบวนการสปัตเตอริงแทน



รูปที่ 4.46 การหลุดลอกของซิ<mark>งค์ออกไซด์ในน้ำตัวอย่างที่ผ่านกา</mark>รวัดซีโอดีด้วยกระบวนการ โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส

#### 4.2.4 สังเคราะห์ซิงค์ออกไซด์ด้วยวิธีการสปัตเตอริง (sputtering) บนพลาสติก พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (polyethylene terephthalate, PET) ที่ผ่านการเคลือบด้วยเงิน (Ag) และอินเดียมทินออกไซด์ (Indium Tin Oxide, ITO)

ก่อนที่จะทำการสังเคราะห์ตัวอย่างซิงค์ออกไซด์ด้วยวิธีการสปัตเตอริง (sputtering) บนพลาสติก PET ขนาด 5x5 ตารางเซนติเมตร ดังรูปที่ 4.47-ก ซึ่งเป็นฐานรองรับ จะถูกนำไปล้างทำ ความสะอาดคราบไขมันและฝุ่นด้วยไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (Isopropyl alcohol; IPA) ล้างด้วย น้ำปราศจากไอออน (Deionized water) เป่าด้วยก๊าซไนโตรเจน แล้วนำชิ้นงานไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที



รูปที่ 4.47 ก) พลาสติก PET ข) เต<mark>รีย</mark>มชิ้นงานใส่ห้องเคลือบสุญญากาศ

พลาสติก PET ซึ่งมีน้ำหนักเบา จะถูกนำไปติดบนกระจกเพื่อป้องกันการเคลื่อนที่เมื่อนำไปใส่ห้อง เคลือบ ดังรูปที่ 4.47-ข ทำการลดความดันภายในห้องเคลือบจนมีสภาวะเป็นสุญญากาศ (ความดัน ประมาณ10<sup>-5</sup> - 10<sup>-6</sup> ทอร์) แล้วทำการเติมด้วยก๊าซอาร์กอนเข้าไปในห้องเคลือบที่ความดัน 2.0 × 10<sup>-2</sup> ทอร์ ทำการสปัตเตอร์เงิน (Ag) เป็นเวลา 3 นาที ก๊าซอาร์กอนจะแตกตัวเป็นไอออน (พลาสม่า) ด้วย สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าพุ่งชนไปที่เป้าและสปัตเตอร์เป้า เป็นผลให้ได้อะตอมเป้าหลุดออกไปสู่ ชิ้นงานแล้วก่อตัวเป็นฟิล์มบางของเงินบนพลาสติก PET จากนั้นเปลี่ยนเป้าสปัตเตอร์จากเงินเป็น อินเดียมทินออกไซด์ (Indium Tin Oxide, ITO) ลดความดันให้จนเป็นเป็นสุญญากาศ เติมด้วยก๊าซ อาร์กอนเข้าไปในห้องเคลือบที่ความดัน 2.0 × 10<sup>-2</sup> ทอร์ แล้วทำการสปัตเตอร์ ITO เป็นเวลา 5 นาที ลงบนพลาสติก PET ที่ถูกเคลือบด้วยเงิน ซึ่งจะสังเกตได้ว่าพื้นผิวของฐานรองรับจะมีความวาว ลดลงเมื่อถูกเคลือบด้วย ITO จะได้ฐานรองรับที่มีการนำไฟฟ้าได้ ดังรูปที่ 4.48-ก และ 4.48-ข



รูปที่ 4.48 ฐานรองรับหลังทำการสปัตเตอร์ด้วย ก) Ag ข) Ag และ ITO ตามลำดับ

เมื่อได้ฐานรองรับแล้วจึงทำการเปลี่ยนเป้าสปัตเตอร์เป็นซิงค์ออกไซด์ ลดความดันและเติมก๊าซอาร์กอน เช่นเดียวกัน ซิงออกไซด์จะถูกสปัตเตอร์ลงไปที่ฐานรองรับ ที่ระยะเวลาแตกต่างกัน คือ 30 และ 120 นาที จะได้ซิงค์ออกไซด์ดังรูปที่ 4.49-ก และ 4.49-ข จากนั้นนำฟิล์มบางซิงค์ออกไซด์ที่ได้ ไปทำการศึกษาคุณสมบัติต่าง ๆ ดังหัวข้อ 4.2.5



รูปที่ 4.49 ซิงค์ออกไซด์ที่<mark>ผ่าน</mark>การสปัตเตอร์เป็นเว<mark>ลา</mark> ก) 30 นาที ข) 120 นาที



#### เครื่อง XRD

จากการนำซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการสปัตเตอริงบน ฐานรองรับพลาสติก PET ที่เคลือบด้วยไทเทเนียมและเงินที่ระยะเลาต่างกัน มาวิเคราะห์ด้วย XRD เพื่อ ตรวจสอบว่าออกไซด์ที่เกิดขึ้นเป็นออกไซด์ของซิงค์ออกไซด์ พบว่า สปัตเตอริงที่เวลา 30 และ 120 นาที พบเพียงพีคของ PET ที่เป็นฐานรองรับ จะปรากฏที่พีค 20 = 25.87° (Faraj and Ibrahim, 2011, Dhakal et al., 2015) แสดงดังรูปที่ 4.50 ซึ่งยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นพีคของซิงค์ออกไซด์ อาจเนื่องมาจากฟิล์มที่ทำการสปัตเตอริงมีความบาง<mark>มา</mark>กจนไม่สามารถวิเคราะห์ผลได้ด้วยเครื่อง XRD



รูปที่ 4.50 XRD ของ ZnO ที่ผ่านการสปัตเตอริงบน PET

#### 4.2.5.2 วิเคราะห์ชนิดและสถานะทางเคมีของธาตุที่เป็นองค์ประกอบที่เกิดบน พื้นผิวของซิงค์ออกไซด์ด้วยเครื่อง XPS

จากการนำซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการสปัตเตอริงบน ฐานรองรับพลาสติก PET ที่เคลือบด้วยไทเทเนียมและเงินไปวิเคราะห์ด้วย XRD แล้วไม่สามารถบอกได้ ว่าตัวอย่างที่เตรียมขึ้นเป็นซิงค์ออกไซด์ จึงนำตัวอย่างไปทำการวิเคราะห์ด้วย XPS จึงสามารถระบุได้ว่า เป็นซิงค์ออกไซด์เนื่องจากปรากฏพีค Binding energy = Zn2p และ O1s (Al-Gaashani et al., 2013) ดังรูปที่ 4.51 จึงอนุมานได้ว่าเป็นซิงค์ออกไซด์ และ C1s เป็นพีคของ PET



รูปที่ 4.51 <mark>XPS ของ ZnO ที่ผ่านการสปัตเตอ</mark>ริงบน PET

จากนั้นนำตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้วัดค่าซีโอดีด้วย กระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส (COD<sub>PEC</sub>) โดยทดลองกับสารอินทรีย์ที่ให้ค่าซีโอดีในเชิงทฤษฎี คือ น้ำตาลกลูโคส (D-glucose) โดยที่เมื่อทำการวัดซีโอดีที่จ่ายความต่างศักย์เพียง 0.1 โวลต์ เป็นเวลา 5 นาที ก็ทำให้ซิงค์ออกไซด์รวมทั้งเงินและอินเดียมทินออกไซด์มีการหลุดลอกออกจากพลาสติก PET ไม่เหมาะสำหรับนำมาวัดค่าซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส จึงทำการเปลี่ยนชนิดของ ฐานรองรับเป็นโพลิไอมายด์ฟิล์มที่เคลือบด้วยทองแดงแทน

#### 4.2.6 สังเคราะห์ซิงค์ออกไซด์ด้วยวิธีการสปัตเตอริง (sputtering) บนโพลิไอมายด์ฟิล์มที่ เคลือบด้วยทองแดง (Copper-clad polyimide film, Cu-clad PI film)

โพลิไอมายด์ฟิล์มที่เคลือบด้วยทองแดง ถูกตัดให้มีขนาด ขนาด 5x5 ตารางเซนติเมตร ดังรูปที่ 4.52-ก มีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้า เป็นฐานรองรับอีกชนิดที่นำมาใช้ในการทดลอง และเมื่อ นำมาทำการสปัตเตอร์ซิงค์ออกไซด์ โดยทำให้ความดันภายในห้องเคลือบมีสภาวะเป็นสุญญากาศ (ความดันประมาณ 10<sup>-5</sup> - 10<sup>-6</sup> ทอร์) แล้วทำการเติมด้วยก๊าซอาร์กอนเข้าไปในห้องเคลือบที่ความดัน 2.0 x 10<sup>-2</sup> ทอร์ สปัตเตอร์ซิงค์ออกไซด์ใช้กำลังที่ 50 วัตต์ ระยะเวลาต่างกัน คือ 60 นาที 120 นาที และ 240 นาที จะได้ซิงค์ออกไซด์ดังรูปที่ 4.52-ข ถึง 4.52-ง ในภายหลังได้เพิ่มเวลา สปัตเตอริงเป็น 480 นาที จะได้ซิงค์ออกไซด์ดังรูปที่ 2.52-จ ซึ่งจะเห็นได้ว่าสีของซิงค์ออกไซด์บน ฐานรองรับจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเพิ่มระยะเวลาในการสปัตเตอริง โดยที่จะเห็นเป็นสีส้มเข้มขึ้นเมื่อใช้ เวลา 60 นาที เปลี่ยนเป็นสีชมพูเมื่อใช้เวลา 120



รูปที่ 4.52 ก) โพลิไอมายด์ฟิล์มที่เคลือบด้วยทองแดง และซิงค์ออกไซด์ที่ผ่านการสปัตเตอร์ เป็นเวลา ข) 60 นาที ค) 120 นาที และ ง) 240 นาที จ) 480 นาที 4.2.7 ศึกษาคุณสมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการสปัตเตอริง (sputtering) บนโพลิไอมายด์ฟิล์มที่เคลือบด้วยทองแดง (Copper-clad polyimide film, Cu-clad PI film)

#### 4.2.7.1 ศึกษาคุณลักษณะพื้นผิวของซิงค์ออกไซด์ด้วยเครื่อง FESEM

หลังจากทำการสังเคราะห์ตัวอย่างซิงค์ออกไซด์ด้วยวิธีการสปัตเตอริง (sputtering) บนโพลิไอมายด์ฟิล์มที่เคลือบด้วยทองแดง (Cu) เติมก๊าซอาร์กอนที่ความดัน 2.0 x 10<sup>-2</sup> ทอร์ กำลังไฟฟ้า 50 วัตต์ เป็นเวลา 60 นาที 120 นาที 240 และ 480 นาที นำไป ทำการศึกษาคุณลักษณะพื้นผิวออกไซด์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดความละเอียดสูง ้ (FESEM) พบว่า เวลา 60 นาที ลักษณะสัณฐานวิทยาของพื้นผิวซิงค์ออกไซด์เริ่มมีลักษณะเป็นทรงกลม ้ขนาด 12- 25 นาโนเมตร เกิดขึ้นอย่างกระจัดกระจายบนพื้นผิวฐานรองรับ แต่เมื่อเวลาเพิ่มขึ้นเป็น ี่ 120 นาที ลักษณะทรงกลมจะเริ่มแตกกระจายตัวเ<mark>ป็น</mark>ผลึก ขนาด 12-63 นาโนเมตร และมีปริมาณมาก ู้ ขึ้นเมื่อเวลาเพิ่มเป็น 240 นาที ผลึกบางส่วนมีข<mark>นา</mark>ดใหญ่ขึ้นในช่วง 12-88 นาโนเมตร แต่เมื่อเพิ่ม ระยะเวลาเป็น 480 นาที ลักษณะสัณฐานวิทย<mark>าของพื้น</mark>ผิวซิงค์ออกไซด์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมี ้ลักษณะคล้ายลำไยที่ถูกคว้านเมล็ด ขนาด 125-375 นาโนเมตร ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ ้องค์ประกอบของธาตุที่มีอยู่ในตัวอย่างโดยใช้ F<mark>E</mark>SEM ใ<mark>น</mark>โหมด EDS พบว่า มีพีคของซิงค์และออกซิเจน ้เกิดขึ้น คิดเป็น 25.98% และ 19.15% ตา<mark>มลำ</mark>ดับ ซึ่งสรุปได้ว่ามีซิงค์ออกไซด์เกิดขึ้นบนโพลิไอมายด์ ้ ฟิล์มที่เคลือบด้วยทองแดง พบทองแดงซึ่งเ<mark>ป็น</mark>ฐานรองรับ <mark>35.</mark>7% นอกจากนั้นยังมีคาร์บอนและซิลิกอน ้เกิดขึ้น 7.18% และ 11.99% จากกา<mark>รอา</mark>ร์คในระบบ แต่เมื่<mark>อเพิ่</mark>มเวลาในการสปัตเตอริงนานขึ้นเป็น ี่ 120 นาที่ 240 และ 480 นาที่ จะเห็<mark>นได้</mark>ว่า ไม่มีคาร์บอนและ<mark>ซิลิก</mark>อนเกิดขึ้นเลย อีกทั้งซิงค์ยังเพิ่มขึ้น เป็น 33.49% 53.66% และ 75.7<mark>1</mark>% ตามลำดับ และออกซิเจนเพิ่มขึ้นเป็น 7.53% 13.88% และ 21.20% ตามลำดับ ดังรูปที่ 4.53 <mark>แสดงให้เห็นว่า จะมีชิง</mark>ค์ออ<mark>กไซ</mark>ด์เพิ่มมากขึ้นเมื่อใช้เวลาใน การสปัตเตอริงนานขึ้น ซึ่งจากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปลักษณะพื้นผิวซิงค์ออกไซด์ที่ได้จาก การสปัตเตอริงบนโพลิไอมาย<mark>ด์ฟิล์มที่เคลือบด้วยทองแดงที่สถาวะที่แตกต่า</mark>งกันได้ดังตารางที่ 4.15





รูปที่ 4.53 ภาพถ่าย FESEM และ EDS สเปกตรัมของซิงค์ออกไซด์ที่สปัตเตอริงที่ระยะเวลา ก) 60 นาที ข) 120 นาที ค) 240 นาที ง) 480 นาที

	สภาวะการสปัตเตอริง			ขนาด		
รูปที่	ความดัน	กำลังไฟฟ้า	ระยะเวลา	(นาโน	ลักษณะสัณฐานวิทยา	
	(ทอร์)	(วัตต์) (นาที)		เมตร)		
4.33-			60	12.25	ทรงกลมขนาดเล็ก	
ก			00	12-23		
4.33-			120	12.63	ผลึกขนาดเล็ก	
ข	0.40-2	50	120	12-05		
4.33-	Zx10 <sup>-</sup>	50	240	10.00	ผลึกขนาดเล็ก	
ค			240	12-00		
4.33-			100	105 275	คล้ายลำไยที่ถูกคว้านเมล็ด	
খ			480	125-375		

ตางรางที่ 4.15 คุณลักษณะพื้นผิวออกไซด์ด้วย FESEM

#### 4.2.7.2 ศึกษาความหนาของ<mark>ซิ</mark>งค์ออ<mark>ก</mark>ไซด์ด้วยเครื่อง Optical profiler

ตัวอย่างซิงค์ออกไซด์ด้วยวิธีการสปัตเตอริง (sputtering) บนโพลิไอมายด์ฟิล์ม ที่เคลือบด้วยทองแดง (Cu) กำลังไฟฟ้า 50 วัตต์ เป็นเวลา 60 นาที 120 นาที 240 และ 480 นาที นำไปทำการศึกษาความหนาด้วยเครื่อง Optical profiler รุ่น WYKO NT1100 บริษัท Veeco พบว่า เมื่อใช้ระยะเวลาในการสปัตเตอริงที่นานขึ้นนอกจากจะทำให้ซิงค์ออกไซด์มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วยังทำให้ ความหนาของซิงค์ออกไซด์เพิ่มขึ้นด้วย โดยที่ 120 นาที 240 และ 480 นาที มีความหนา 200-400 400-600 และ 600-1,200 นาโนเมตร ตามลำดับ ส่วนที่ระยะเวลา 60 นาที ไม่สามารถวัดความหนาได้ ด้วยเครื่องมือนี้เนื่องจากซิงค์ออกไซด์ค่อนข้างบาง จากข้อมูลสรุปได้ดังตารางที่ 4.16

เวลาที่ใช้ สปัตเตอริง (นาที)	ภาพสามมิติ	ความหนา (นาโนเมตร)
60	-	ไม่สามารถ วัดได้

ตารางที่ 4.16 ความหนาของซิงค์ออกไซด์เมื่อสปัตเตอริงด้วยระยะเวลาต่าง ๆ

เวลาที่ใช้ สปัตเตอริง (นาที)	ภาพสามมิติ	ความหนา (นาโนเมตร)
120	24 20 15 10 05 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	200-400
240		400-600

ตารางที่ 4.16 ความหนาของซิงค์ออกไซด์เมื่อสปัตเต<sub>อริง</sub>ด้วยระยะเวลาต่าง ๆ (ต่อ)

เวลาที่ใช้ สปัตเตอริง	ภาพสามมิติ	ความหนา (นาโนเมตร)
(นาที)		
480		600-1,200

ตารางที่ 4.16 ความหนาของซิงค์ออกไซด์เมื่อสปัตเตอริงด้วยระยะเวลาต่าง ๆ (ต่อ)



#### 4.2.7.3 วิเคราะห์การดูดกลื่นแสงของซิงค์ออกไซด์ด้วยเครื่อง UV-VIS

#### spectrophotometer

จากการวิเคราะห์การดูดกลืนแสงของซิงค์ออกไซด์ด้วยเครื่อง UV-VIS spectrophotometer โดยได้ทำการวัดการดูดกลืนแสงของตัวอย่าง ที่ผ่านการสปัตเตอริง (sputtering) บนโพลิไอมายด์ฟิล์มที่เคลือบด้วยทองแดง (Cu) กำลังไฟฟ้า 50 วัตต์ เป็นเวลา 60 นาที 120 นาที 240 และ 480 นาที ดังรูปที่ 4.54 พบว่า ซิงค์ออกไซด์สามารถดูดกลืนแสงได้ดีในช่วงยูวี โดย ที่การดูดกลืนแสงจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ใช้ในการสปัตเตอริง อีกทั้งยังสามารถดูดกลืนแสงในช่วง วิสิเบิลได้เพิ่มขึ้นด้วย ยกเว้นที่ 60 นาที ที่การดูดกลืนแสงมีค่าสูงที่สุด



รูปที่ 4.54 UV-VIS ของซิงค์ออกไซด์ที่ผ่านการสปัตเตอริงที่ระยะเวลาต่างกัน คือ 60 นาที 120 นาที 240 นาที และ 480นาที

#### 4.2.7.4 ศึกษาการตอบสนองต่อแสงของตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์

ทำการศึกษาการตอบสนองต่อแสง โดยฉายแสงจากหลอดยูวี (UV-LED) ขนาด 10 วัตต์ ความยาวคลื่น 365 นาโนเมตร และจ่ายความต่างศักย์คงที่ที่ 0.2 โวลต์ ไปยังตัวเร่ง ปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการสปัตเตอริง และทำการเปิด-ปิดไฟ สลับกันรอบละ 20 วินาที จากการทดลอง พบว่า การตอบสนองของตัวเร่งปฏิกิริยาในที่มืดเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยซึ่งจะไม่ เกิดการออกซิเดชันทางเคมี แต่เมื่อมีการฉายแสงยูวีไปยังตัวเร่งปฏิกิริยา กระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการวัด การตอบสนองต่อแสงมีค่าสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่าซิงค์ออกไซด์สามารถตอบสนองต่อแสงในช่วงยูวีได้ดี และยิ่งดีขึ้นเมื่อมีการจ่ายความต่างศักย์ไฟฟ้า ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของ Mu et al., 2011 และ



Wang et al., 2013 อย่างไรก็ตาม เมื่อทำการฉายไฟไปยังตัวเร่งปฏิกิริยาในเวลาที่นานขึ้นจะเห็นได้ว่า กระแสที่วัดได้ลดลงประมาณ 10% ในทุก ๆ รอบของการวัด ผลการทดลองที่ได้แสดงดังรูปที่ 4.55

รูปที่ 4.55 แสดงการ<mark>ตอบ</mark>สนองต่อแสงของตัว<mark>เร่งป</mark>ฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ (ก่อนปรับปรุงแหล่งกำเนิดแสง)

ในภายหลัง จึงได้ทำการปรับปรุงที่แหล่งกำเนิดแสงโดยการเพิ่มพัดลมระบายอากาศ เพื่อลดอุณหภูมิ เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทำให้ความเข้มแสงของหลอดไฟลดลง (รัฐพล ดามัน, 2555) และทำการทดสอบโดยการวัดค่าความส่องสว่างของแสงด้วยลักซ์มิเตอร์ (lux meter) เพื่อเป็น ตัวแทนในการศึกษาความเสถียรของแสงที่ใช้ แสดงในภาคผนวก ข.2 เมื่อทำการปรับปรุงที่แหล่งกำเนิด แสงแล้วทำการวัดการตอบสนองต่อแสงของตัวเร่งปฏิกิริยา ดังการทดลองข้างต้น พบว่า กระแสที่วัดได้ ในแต่ละรอบมีความเสถียรและใกล้เคียงกันมากขึ้น ดังรูปที่ 4.56 นอกจากนี้เมื่อทำการเปิดหลอดไฟ ตลอดการศึกษา แล้วทำการปิดแหล่งจ่ายความต่างศักย์ไฟฟ้าและเปิดแหล่งจ่ายความต่างศักย์ไฟฟ้า สลับกันแทน พบว่า กระแสที่ได้ยิ่งมีความเสถียรและใกล้เคียงกันมากขึ้น ดังรูปที่ 4.57



รูปที่ 4.56 แสดงการตอบสนองต่อแสงข<mark>อ</mark>งตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ (หลังปรับปรุงแห<mark>ล่ง</mark>กำเนิดแสง<mark>) ปิ</mark>ด-เปิดไฟสลับกัน



รูปที่ 4.57 แสดงการตอบสนองต่อแสงของตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ (หลังปรับปรุงแหล่งกำเนิดแสง**)** ปิด-เปิดแหล่งจ่ายความต่างศักย์สลับกัน 4.2.8.1 ทดสอบความเสถียรของซิงค์ออกไซด์โดยการวัดซ้ำของสารละลาย อิเล็กโตรไลต์ด้วยเครื่องโพเทนชิโอสแตท (Potentiostat)

นำตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้วัดค่าซีโอดีด้วยกระบวนการ โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส (COD<sub>PEC</sub>) โดยใช้ซิงค์ออกไซด์เป็นขั้วไฟฟ้าใช้งาน (Working Electrode) ใช้ แพลทินัมเป็นขั้วไฟฟ้าร่วม (Counter electrode) และใช้ขั้วไฟฟ้าอิเล็กโทรดแบบ ซิลเวอร์/ซิลเวอร์คลอไรด์ (Ag/AgCl) เป็นขั้วไฟฟ้าอ้างอิง ต่อเข้ากับเครื่องโพเทนชิโอสแตท (F9, SUT) เพื่อวัดกระแสที่เกิดขึ้นเมื่อสารละลายถูกออกซิไดซ์บนพื้นผิวซิงค์ออกไซด์ ใช้แหล่งกำเนิดแสงจากหลอดยู วิแอลอีดี (UV LED) ขนาด 10 วัตต์ ความยาวคลื่น 365 นาโนเมตร เครื่องมือวัด ดังรูปที่ 4.58 เมื่อทำการ วัดสารละลายอิเล็กโตรไลต์ Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 0.1 โมลาร์ (Blank) โดยใช้แผ่นเดิมวัดซ้ำจำนวน 5 ครั้ง และเปลี่ยน น้ำตัวอย่างทุกครั้งแบบไม่ขยับตำแหน่งของขั้วไฟฟ้า ได้ผลดังกราฟรูปที่ 4.59 เมื่อนำการตอบสนองใน รูปของกระแสมาคำนวณหาพื้นที่ใต้กราฟ (Q) พบว่ามีการลดลงของพื้นที่ใต้กราฟเมื่อทำการวัดซ้ำโดย ใช้ซิงค์ออกไซด์แผ่นเดิม Q<sub>1</sub> ถึง Q<sub>5</sub> เท่ากับ 9.83455 2.74006 1.32620 1.02387 และ 0.76696 คู ลอมบ์ ตามลำดับ และข้อมูลที่ได้ค่อนข้างหยาบเนื่องจากจุดจำนวนข้อมูลที่เก็บได้จากเครื่องโพเทนซิ



รูปที่ 4.58 เครื่องโพเทนซิโอสแตทที่ใช้ในกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส



รูปที่ 4.59 ทดสอบการวัดซ้ำของสารละลายอิเล็กโตรไลต์ Na2SO4 0.1 โมลาร์

#### 4.2.8.2 วัดค่าซีโอด<mark>ีด้วย</mark>เครื่องมัลติมิเตอร์ (multimeter)

นำตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้วัดค่าซีโอดีด้วยกระบวนการ โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส (COD<sub>PEC</sub>) โดยใช้ซิงค์ออกไซด์เป็นขั้วไฟฟ้าใช้งาน (Working Electrode) ใช้ แกรไฟต์เป็นขั้วไฟฟ้าร่วม (Counter electrode) และใช้ขั้วไฟฟ้าอิเล็กโทรดแบบซิลเวอร์/ซิลเวอร์คลอไรด์ (Ag/AgCl) เป็นขั้วไฟฟ้าอ้างอิง ต่อเข้ากับเครื่องมัลติมิเตอร์เพื่อวัดกระแสที่เกิดขึ้นเมื่อสารละลายถูก ออกซิไดซ์บนพื้นผิวซิงค์ออกไซด์ ใช้แหล่งกำเนิดแสงจากหลอดยูวีแอลอีดี (UV LED) ขนาด 10 วัตต์ ความยาวคลื่น 365 นาโนเมตร เครื่องมือวัด ดังรูปที่ 4.60



รูปที่ 4.60 เครื่องมัลติมิเตอร์ที่ประยุกต์ใช้ในกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสเพื่อวัดซีโอดี

#### ทดลองเบื้องต้นในการวัดซีโอดีด้วยกระบวนการ

#### โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส

4.2.8.2.1

ทำการทดลองเบื้องต้นในการวัดวัดค่าซีโอดีด้วย กระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส โดยทดลองกับสารอินทรีย์ที่ให้ค่าซีโอดีในเชิงทฤษฎี คือ กลูโคส (D-glucose) โดยที่นำซิงค์ออกไซด์ที่ทำการสังเคราะห์ด้วยวิธีการสปัตเตอริง (sputtering) เป็นเวลา 60 นาที บนโพลิไอมายด์ฟิล์มที่เคลือบด้วยทองแดง (Cu) มาทำการวัดซีโอดีที่จ่ายความต่างศักย์ 0.1 ์ โวลต์ เป็นเวลา 5 นาที ความเข้มข้นของกลุโคส 10 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ใช้ปริมาตรน้ำ 3 มิลลิลิตร ผลการวัดกระแสที่ได้เป็นดังรูปที่ 4.61-ก และ 4.61-ข ซึ่งเห็นได้ว่ากระแสที่วัดได้มีความสม่ำเสมอ และ เมื่อเปรียบเทียบกระแสที่เกิด<sup>์</sup>ขึ้นจากการวัดความเข้มข้นของกลูโคสที่ต่างกันพบว่า เมื่อความเข้มข้นมาก ้ขึ้นกระแสที่วัดได้ก็มากขึ้นตามไปด้วย และเมื่อทำการจ่ายศักย์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น 0.2 โวลต์ ทำให้กระแส ้ ที่วัดได้มีค่าสูงขึ้นไปด้วย และเมื่อวัดความเข้มข้นข<mark>อง</mark>กลูโคสมากขึ้นกระแสที่วัดได้ก็มากขึ้นตามไปด้วย เช่นกัน และเมื่อนำซิงค์ออกไซด์ที่ทำการสังเคราะห์ด้วยวิธีการสปัตเตอริง (sputtering) เป็นเวลา 120 .และ 240 นาที บนโพลิไอมายด์ฟิล์มที่เคลือบ<mark>ด้วยทอ</mark>งแดง (Cu) มาวัดซีโอดีที่จ่ายความต่างศักย์ 0.1 โวลต์ และ 0.2 โวลต์ ดังรูปที่ 4.62-ก 4.62-ข 4.63-ก และ 4.63-ข แนวโน้มของกระแสที่เกิดขึ้นก็ ้คล้ายดังเช่นเดียวกันกับซิงค์อออกไซด์ที่สปัตเต<mark>อ</mark>ริง (sputtering) เป็นเวลา 60 นาที (ในแต่ละสภาวะ ของการทดลองจะใช้แผ่นเดิมวัดเปรียบเทีย<mark>บระ</mark>หว่าง I <sub>(total)</sub> ของน้ำตัวอย่างที่มีสารอินทรีย์กับ I <sub>(blank)</sub> ของน้ำตัวอย่างที่ไม่มีสารอินทรีย์) พื้นที่ใต้<mark>กรา</mark>ฟที่ได้นำมา<mark>คำ</mark>นวณหาค่าซีโอดีโดยอาศัยกฎการแยกสาร ด้วยไฟฟ้าของฟาราเดย์ (Faraday' la<mark>w) Q</mark>net = <sub>II(total)</sub> dt - <sub>II(blank)</sub> dt = Q<sub>total</sub> - Q<sub>blank</sub> มาใช้หาความ เข้มข้นเมื่อสารอินทรีย์ถูกออกซิไดซ์ ไ<mark>ด้ดัง</mark>ตารางที่ 4.17



รูปที่ 4.61 การตอบสนองของกระแสไฟฟ้าของตัวเร่งปฏิกิริยาที่สังเคราะห์โดยการสปัตเตอริง เป็นเวลา 60 นาที ในกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสของซีโอดี (กลูโคส) 10 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร สารอิเล็กโทรไลต์ Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 0.1 โมลาร์ ระยะเวลา 5 นาที ปริมาตรน้ำ 3 มิลลิลิตร จ่ายความต่างศักย์คงที่ ก) 0.1 โวลต์ ข) 0.2 โวลต์



รูปที่ 4.62 การตอบสนองของกระแสไฟฟ้าของตัวเร่งปฏิกิริยาที่สังเคราะห์โดยการสปัตเตอริงเป็นเวลา 120 นาที ในกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสของซีโอดี (กลูโคส) 10 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร สารอิเล็กโทรไลต์ Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 0.1 โมลาร์ ระยะเวลา 5 นาที ปริมาตรน้ำ 3 มิลลิลิตร จ่ายความต่างศักย์คง<mark>ที่ ก</mark>) 0.1 โวล<mark>ต์ ข</mark>) 0.2 โวลต์



รูปที่ 4.63 การตอบสนองของกระแสไฟฟ้าของตัวเร่งปฏิกิริยาที่สังเคราะห์โดยการสปัตเตอริง เป็นเวลา 240 นาที ในกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสของซีโอดี (กลูโคส) 10 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร สารอิเล็กโทรไลต์ Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 0.1 โมลาร์ ระยะเวลา 5 นาที ปริมาตรน้ำ 3 มิลลิลิตร จ่ายความต่างศักย์คงที่ ก) 0.1 โวลต์ ข) 0.2 โวลต์

	คว	ามต่างศักย์ (	).1 โวลต์		ความต่างศักย์ 0.2 โวลต์				
เวลาสปัตเตอริง	Q <sub>(total)</sub> -	COD <sub>(PEC)</sub>		Q <sub>(total)</sub> -	Q(blank)	COD <sub>(PEC)</sub>			
(นาที)	10	50	10	50	10	50	10	50	
	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
60	0.75120	2.85342	20.76	78.86	-0.82906	0.60704	-	16.78	
120	0.05414	2.73777	1.50	75.67	1.19907	2.52479	33.14	69.78	
240	-2.44729	0.62418	-	17.25	-4.29882	2.01364		55.65	

ตารางที่ 4.17 พื้นที่ใต้กราฟ (Q) และค่าซีโอดีที่วัดได้จากกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส

เมื่อทำการทดลองโดยเปลี่ยนแผ่นในการวัดซีโอดีเปรียบเทียบระหว่าง I <sub>(total)</sub> ของน้ำตัวอย่างที่มีสารอินทรีย์กับ I <sub>(blank)</sub> ของน้ำตัวอย่างที่ไม่มีสารอินทรีย์ จะเห็นได้ว่าไม่สามารถ แปลผลจากกราฟได้ เนื่องจากกระแสที่วัดได้มีค่าใกล้เคียงกันมากทั้งที่ความเข้มข้นของกลูโคสสูงถึง 100 มิลลิกรัมต่อลิตร แสดงดังรูปที่ 4.64



### <sup>ย</sup>าลัยเทคโนโล<sup>ะ</sup>

รูปที่ 4.64 การตอบสนองของกระแสไฟฟ้าของตัวเร่งปฏิกิริยาที่สังเคราะห์โดยการสปัตเตอริง เป็นเวลา 120 นาที ในกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสของซีโอดี (กลูโคส) 100 มิลลิกรัมต่อลิตร Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 0.1 โมลาร์ ระยะเวลา 5 นาที ปริมาตรน้ำ 3 มิลลิลิตร จ่าย ความต่างศักย์คงที่ 0.2 โวลต์

#### 4.2.8.2.2 เปรียบเทียบขั้วไฟฟ้าร่วม

เปรียบเทียบการใช้ขั้วไฟฟ้าร่วมต่างชนิดกัน ได้แก่ แกรไฟต์ และแพลทินัม ใช้ซิงค์ออกไซด์ที่ผ่านการสปัตเตอริงเป็นเวลา 120 นาที พื้นที่ทำปฏิกิริยาขนาด 1x1 ตารางเซนติเมตร เป็นขั้วไฟฟ้าใช้งาน ทำโดยการวัดการตอบสนองของกระแสไฟฟ้าในสารละลาย โซเดียมซัลเฟต (Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) 0.1 โมลาร์ ปริมาณ 3 มิลลิลิตร จ่ายความต่างศักย์ไฟฟ้า 0.2 โวลต์ เป็นเวลา 5 นาที พบว่าพื้นที่ใต้กราฟของกระแสไฟฟ้าที่ได้จากการวัด Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 0.1 โมลาร์ (Q<sub>b</sub>) เมื่อใช้แกรไฟต์ เป็นขั้วไฟฟ้าร่วมแล้วทำการวัดซ้ำเป็นจำนวน 3 ซ้ำ ได้ค่า Q<sub>b</sub> = 20.24316 18.82898 และ 19.13513 คูลอมบ์ ตามลำดับ และเมื่อเปลี่ยนขั้วไฟฟ้าร่วมเป็นแพลทินัม พบว่า Q<sub>b</sub> = 17.02607 15.92140 และ 16.62138 คูลอมบ์ ตามลำดับ ดังรูปที่ 4.65-ก และ 4.65-ข แสดงให้เห็นว่าการใช้ขั้วไฟฟ้าร่วมที่ต่าง ชนิดกันให้ผลการวัดที่ไม่แตกต่างกัน แต่เนื่องจากการออกแบบถังปฏิกรณ์แต่เดิมทีที่ใช้แกรไฟต์เป็น ขั้วไฟฟ้าร่วมทำให้ต้องวางแกรไฟต์ในแนวนอนขนานกับถังปฏิกรณ์ รอยเชื่อมต่อระหว่างแกรไฟต์และ สายไฟที่ต่อปากคีบไฟฟ้าต้องจุ่มลงในสารละลายซึ่งอาจทำให้เกิดการรั่วของไฟและสายไฟขาดเมื่อทำ ความสะอาดแกรไฟต์ก่อนและหลังใช้งาน จึงเปลี่ยนมาใช้แพลทินัมเป็นขั้วไฟฟ้าร่วมแทน



รูปที่ 4.65 แสดงการเปรียบ<mark>เทีย</mark>บพื้นที่ใต้กราฟที่เกิดขึ้นจากการวัด<mark>กระแ</mark>สของ Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 0.1 โมลาร์ เมื่อใช้ขั้วไฟฟ้าร่วมเ<del>ป็น ก</del>) แกรไฟต์ และ ข) แพลทินัม

4.2.8.2.3 ตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำและความเสถียรของวิธีการ หาค่าซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสโดยใช้ซิงค์ออกไซด์ที่สปัตเตอริง 120 นาที เป็น ตัวเร่งปฏิกิริยา

#### 1) ทำการวิเคราะห์หาค่าซีโอดีด้วยกระบวนการ โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส (COD<sub>PEC</sub>) ของกลูโคสที่ความเข้มข้นที่ต่าง ๆ

10

จากการศึกษาคุณสมบัติของซิงค์ออกไซด์โดยใช้ FESEM ในโหมด EDS พบว่าการสปัตเตอริง (sputtering) เป็นเวลา 60 นาที ได้ซิงค์ออกไซด์ในปริมาณ น้อย จึงไม่นำมาใช้ในการทดลองในการวัดซีโอดี โดยในที่นี้จึงเลือกตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ที่ทำการ สังเคราะห์ด้วยวิธีการสปัตเตอริงเป็นเวลา 120 นาที บนโพลิไอมายด์ฟิล์มที่เคลือบด้วยทองแดงมาทำ การวัดซีโอดีความเข้มข้นตั้งแต่ 0-500 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยที่ทำการล้างแผ่นซิงค์ออกไซด์และเป่าด้วย ก๊าซไนโตรเจนทุกครั้งก่อนทำการทดลองวัดค่าซีโอดีโดยวัดซีโอดีจากความเข้มข้นต่ำไปสูง (0-500 มิลลิกรัมต่อลิตร) ผลที่ได้แสดงดังรูปที่ 4.66-ก จากนั้นใช้แผ่นเดิมความเข้มข้นสูงไปต่ำ (500-0 มิลลิกรัมต่อลิตร) ผลที่ได้แสดงดังรูปที่ 4.66-ข เพื่อดูความแม่นยำของค่าซีโอดีที่ทำการวัดได้ จากนั้นนำมาคำนวณหาค่าซีโอดีด้วย Faraday' law ผลที่ได้แสดงดังตารางที่ 4.18



รูปที่ 4.66 การวัดซีโอดีด้<mark>วยก</mark>ระบวนก<mark>ารโพ</mark>โตอิเล็กโตรคะตะไลซิส ก) วัดซีโอดีจากความเข้มข้นต่ำไปสูง ข) วัดซีโ<mark>อดีจ</mark>ากความเข้มข้นสูงไป<mark>ต่ำ</mark>

COD <sub>(Theory)</sub> (mg/L)	$Q_t - Q_b = Q_{net}$	COD <sub>(PEC)</sub> (mg/L)	COD <sub>(Theory)</sub> (mg/L)	$Q_t - Q_b = Q_{net}$	COD <sub>(PEC)</sub> (mg/L)
5	1.21806	33.66	500	8.13466	224.83
10	0.99547	27.51	200	11.9038	329
50	1.67173	46.20	100	6.05180	167.26
100	3.54542	97.99	50 50	0.36691	10.14
200	10.9753	303.34	10	3.83602	106.02
500	7.63870	211.12	5	3.04671	84.21

ตารางที่ 4.18 ค่าซีโอดีที่วัดจากความเข้มข้นต่ำไปสูงและสูงไปต่ำ

จากนั้นเมื่อนำไปทำการอินทริเกรตหาพื้นที่ใต้

กราฟ (Q<sub>net</sub>) ได้ทำการสร้างกราฟมาตรฐานระหว่างค่า Q<sub>net</sub> กับความเข้มข้นของซีโอดีทางทฤษฎีของ สารละลายมาตรฐานกลูโคส โดยตัดข้อมูลบางค่า ดังรูปที่ 4.67 จะได้สมการเส้นตรง y = 0.05268x – 0.35567 และ R<sup>2</sup> = 0.9527 สำหรับการวัดซีโอดีจากความเข้มข้นต่ำไปสูง และรูปที่ 4.68 สำหรับการวัดซีโอดีจากความเข้มข้นสูงไปต่ำ จะได้สมการเส้นตรง y = 0.0487x + 1.89939 และ R<sup>2</sup> = 0.0.9099



รูปที่ 4.67 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าซีโอดีทางท<mark>ฤ</mark>ษฎีและ Q<sub>net</sub> จากกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส จากการวัดซีโอดีที่ความเข้มข้นต่ำไ**ปสูง** 



รูปที่ 4.68 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าซีโอดีทางทฤษฎีและ Q<sub>net</sub> จากกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส จากการวัดซีโอดีที่ความเข้มข้นสูงไปต่ำ

#### 2) ทำการวิเคราะห์หาค่าซีโอดีด้วยกระบวนการ โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส (COD<sub>PEC</sub>) ของกลูโคสที่ความเข้มข้นเดียวกัน

นำซิงค์ออกไซด์ที่ทำการสังเคราะห์ด้วยวิธีการ สปัตเตอริงเป็นเวลา 120 นาที บนโพลิไอมายด์ฟิล์มที่เคลือบด้วยทองแดงมาทำการวัดซีโอดีด้วย กระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส COD<sub>PEC</sub> ของกลูโคสที่ความเข้มข้นเดียวกัน คือ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ทำการวิเคราะห์เป็นจำนวน 4 ซ้ำ (n=4) โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาตัวเดียวกัน จ่ายความต่างศักย์ 0.2 โวลต์ แล้วทำการวัดซีโอดี เป็นเวลา 5 นาที ปริมาตรน้ำตัวอย่าง 3 มิลลิลิตร โดยอาศัยกฏการแยกสารด้วย ไฟฟ้าของฟาราเดย์ มาใช้หาความเข้มข้นเมื่อสารอินทรีย์ถูกออกซิไดซ์ ได้ผลดังตารางที่ 4.19

ครั้งที่ (COD <sub>(Theory)</sub> = 100 mg/L)	COD <sub>(PEC)</sub> (mg/L)
1	109.73
2	92.06
3	110.22
4	103.98
ค่าเฉลี่ย	104.00
S.D.	8.45

ตารางที่ 4.19 แสดงค่าซีโอดีที่ได้จากกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสจากการวัดซ้ำ

ผลของการใช้ซ้ำของตัวเร่งปฏิริยาซิงค์ออกไซด์
3.1) วัดซีโอดีของกลูโคส

นำตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ที่ทำการ สังเคราะห์ด้วยวิธีการสปัตเต<mark>อริงเป็นเวลา 120 นาที บนโพลิไอมายด์ฟิล์ม</mark>ที่เคลือบด้วยทองแดงมาทำ การวัดซีโอดีของกลูโคสความเข้มข้นตั้งแต่ 0-500 มิลลิกรัมต่อลิตร และเนื่องมาจากการใช้ซ้ำจะทำให้ คุณภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ลดลง ซึ่งในเบื้องต้นสังเกตได้จากสีของตัวเร่งปฏิกิริยาที่เปลี่ยนแปลงไป ดังตารางที่ 4.20

## ้<sup>วักยา</sup>ลัยเทคโนโลยีส์<sup>ร</sup>

ตารางที่ 4.20 แสดงลักษณะทางกายภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อผ่านการใช้ซ้ำ

ก่อน		หลังวัดซีโอดีครั้งที่										
วัด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										135		*
4	1	1		i		4	n.		1	1	1	1.

ฉะนั้น จึงทำการวัดโดยแบ่งความเข้มข้น ของซีโอดีออกเป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์แผ่นเดียวกันและแต่ละกลุ่ม จะต้องทำการวัด I<sub>(blank)</sub> ด้วยทุกครั้ง โดยที่กลุ่มแรกวัดซีโอดีเข้มข้น 5 - 50 มิลลิกรัมต่อลิตร กลุ่มที่สอง วัดซีโอดีเข้มข้น 100 - 500 มิลลิกรัมต่อลิตร จ่ายความต่างศักย์ 0.2 โวลต์ แล้วทำการวัดซีโอดีเป็นเวลา 5 นาที แต่ละความเข้มข้นทำการวัดซ้ำจำนวน 3 ซ้ำ จะได้กราฟดังรูปที่ 4.69 ซึ่งนำมาคำนวณเป็นค่าซี โอดีที่ได้จากกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส (n=3) แสดงดังตารางที่ 4.21



รูปที่ 4.69 การวัดซีโอดีจากกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส ความเข้มข้นของซีโอดี ก) 5 10 แล<mark>ะ 5</mark>0 ม<mark>ิลลิกรัมต่อลิตร</mark> ข) 100 200 แล<mark>ะ</mark> 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

COD ( 4)		Q <sub>t</sub> -Q <sub>b</sub> =	Q <sub>net</sub> ครั้งที่	10	
COD <sub>(Theory)</sub> (mg/L)	7,1	2	3	เฉลี่ย	COD <sub>(PEC)</sub> (mg/L)
5	1.41279	1.36360	1.48647	1.42095	39.27252
10	-2.06145	-1.74911	-1.5887	-1.79975	_
50	0.07218	0.73922	0.39666	0.40269	11.12951
100	3.95229	3.31750	3.98693	3.75224	103.705
200	5.95832	4.97604	3.82748	4.92061	135.9966
500	6.57629	7.21126	7.65302	7.14686	197.5259

ตารางที่ 4.21 แสดงค่าซีโอดีข<mark>องกลูโค</mark>สที่ได้จากกระบวนการโฟโ<mark>ตอิเล็กโต</mark>รคะตะไลซิส

และเมื่อนำมาหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าซีโอดีทางทฤษฎีและค่าซีโอดีจากกระบวนการ โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสจะได้ความสัมพันธ์ ดังรูปที่ 4.70 และได้สมการเส้นตรง y = 0.0127x + 1.40362 และ R<sup>2</sup> = 0.8604



รูปที่ 4.70 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าซีโอดีทางทฤษฎีและค่าซีโอดีจากกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ

3.2) วัดซีโอดีของโพแทสเซียมไฮโดรเจนพลาเลต

<mark>จากการน</mark>ำตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ที่

ทำการสังเคราะห์ด้วยวิธีการสปัตเตอริงเป็นเวลา 120 นาที บนโพลิไอมายด์ฟิล์มที่เคลือบด้วยทองแดง มาทำการวัดซีโอดีของ KHP ความเข้มข้นตั้งแต่ 0-150 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ละความเข้มข้นทำการวัดซ้ำ จำนวน 3 ซ้ำ ความเข้มข้นของสารอิเล็กโทรไลต์โซเดียมซัลเฟต 0.1 โมลาร์ ปริมาตรน้ำ 3 มิลลิลิตร ระยะเวลาที่ใช้ในการหาค่าซีโอดี 5 นาที จ่ายความต่างศักย์ที่ 0.2 โวลต์ จะได้กราฟดังรูปที่ 4.71 พบว่า ซีโอดี I<sub>(total)</sub> ที่ความเข้มข้น 5 และ 10 มิลกรัมต่อลิตร นั้น กระแสที่วัดได้มีค่าต่ำกว่ากระแส ของแบลงค์ I<sub>(blank)</sub> ส่วน 50 100 และ 150 มิลกรัมต่อลิตร มีค่าสูงกว่าแบลงค์ ซึ่งนำมาคำนวณเป็น ค่าซีโอดีที่ได้จากกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส (n=3) แสดงดังตารางที่ 4.22



รูปที่ 4.71 การวัดซีโอดีของ KHP จากกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส ความเข้มข้นของซี<mark>โอดี</mark> 0-150 มิลิ<mark>กรัม</mark>ต่อลิตร

1	2	3	<b>เ</b> ฉลี่ย	COD <sub>(PEC)</sub> (mg/L)
-1.73076	-1.58553	-2.67132	-1.99587	-
-3.1137	-2.73423	-2.6261	-2.82467	_
1.148883	1.739543	2.007293	1.63191	45.10
6.269613	7.276323	7.731013	7.09232	196.02
6.143393	5.226803	5.462213	5.61080	155.07
	1 -1.73076 -3.1137 1.148883 6.269613 6.143393	Qt-Qb =   1 2   -1.73076 -1.58553   -3.1137 -2.73423   1.148883 1.739543   6.269613 7.276323   6.143393 5.226803	Qt-Qb = Unet ครั้งที่123-1.73076-1.58553-2.67132-3.1137-2.73423-2.73423-2.62611.1488831.7395436.2696137.2763237.7310136.1433935.2268035.462213	Qt-Qb = Unet ครั้งที่123เฉลี่ย-1.73076-1.58553-2.67132-1.99587-3.1137-2.73423-2.6261-2.824671.1488831.7395432.0072931.631916.2696137.2763237.7310137.092326.1433935.2268035.4622135.61080

ตารางที่ 4.22 แสดงค่าซีโอดีของ KHP ที่ได้จากกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส

ยาลยเทคโนโลย

จากนั้นเมื่อนำไปทำการอินทริเกรตหา

พื้นที่ใต้กราฟ (Q<sub>net</sub>) จากนั้นได้ทำการสร้างกราฟมาตรฐานระหว่างค่า Q<sub>net</sub> กับความเข้มข้นของซีโอดี ทางทฤษฎีของสารละลายมาตรฐาน KHP ดังรูปที่ 4.72 จะได้สมการเส้นตรง y = 0.04459x + 0.23984 และ R<sup>2</sup> = 0.7514 ซึ่งจะเห็นได้ว่าได้ค่า R<sup>2</sup> ค่อนข้างต่ำ



รูปที่ 4.72 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าซีโอดีทางทฤษฎีและค่าซีโอดีจากกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส ที่ความเข้มข้นต่า<mark>ง</mark> ๆ

4)

#### <mark>ศึกษาการ</mark>ตอบสนองของซิงค์ออกไซด์ที่

#### ความต่างศักย์ต่าง ๆ

จากการศึกษาผลของการจ่ายความต่าง

ศักย์ไฟฟ้าของน้ำตัวอย่างที่มีเพียงสารละลายอิเล็กโทรไลต์โซเดียมซัลเฟต 0.1 โมลาร์ (Q<sub>(b)</sub>) กับ สารละลายอิเล็กโทรไลต์โซเดียมซัลเฟต 0.1 โมลาร์ที่มีสารอินทรีย์ที่ให้ค่าซีโอดีในเชิงทฤษฎี คือ โพแทสเซียมไฮโดรเจนพลาเลต (Potassium hydrogen phthalate, KHP) ที่มีความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อลิตร (Q<sub>(total)</sub>) โดยใช้แผ่นซิงค์ออกไซด์เดียวกันวัดสลับกันระหว่าง Q<sub>(blank</sub>) และ Q<sub>(total)</sub> ที่ ความต่างศักย์ตั้งแต่ 0.1 โวลต์ จนถึง 1.0 โวลต์ เพื่อตรวจสอบดูว่าที่การจ่ายความต่างศักย์ใดเหมาะสม สำหรับการวัดซีโอดี พบว่า ทั้ง Q<sub>(blank</sub>) และ Q<sub>(total)</sub> มีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อจ่ายความต่างศักย์ที่สูงขึ้น แต่เมื่อ พิจารณาที่ความต่างศักย์ใด ๆ ยังไม่สามารถระบุได้ว่า ควรจ่ายความต่างศักย์เท่าใดเมื่อทำการวัดซีโอดี เนื่องจาก Q<sub>(blank)</sub> และ Q<sub>(total)</sub> มีค่าค่อนข้างใกล้เคียงกัน (n=3) ดังรูปที่ 4.73 ผลของการวัดซ้ำแสดงดัง ภาคผนวก ข.3



รูปที่ 4.73 การจ่ายความต่า<mark>ง</mark>ศักย์ไฟ<mark>ฟ้</mark>าของ Q<sub>(blank)</sub> และ Q<sub>(total)</sub>

5)

#### <mark>ผล</mark>ของการเคลื่อนย้ายตำแหน่งอุปกรณ์

#### ในการวัดซีโอดี

จากการทดสอบโดยการวัดและคำนวณ

พื้นที่ใต้กราฟ (Q) ของสารละลายอิเล็กโทรไลต์โซเดียมซัลเฟต 0.1 โมลาร์ ภายใต้แสงยูวีความยาวคลื่น 365 นาโนเมตร และจ่ายความต่างศักย์ 0.2 โวลต์ ไปยังตัวเร่งปฏิริยาซิงค์ออกไซด์ที่ผ่านการสปัตเตอริง เป็นเวลา 120 นาที ขนาด 1x1 ตารางเซนติเมตร โดยที่ทำการเพิ่มปริมาตรน้ำตัวอย่างครั้งละ 0.5 มิลลิลิตร ในการวัดแต่ละรอบ ๆ ละ 3 นาที โดยที่ไม่มีการเคลื่อนย้ายตำแหน่งอุปกรณ์ในการวัด พบว่า พื้นที่ใต้กราฟอยู่ในช่วง 1.99 -2.4 คูลอมบ์ แสดงให้เห็นว่าปริมาตรน้ำที่ต่างกันของสารละลาย อิเล็กโทรไลต์โซเดียมซัลเฟต 0.1 โมลาร์ ซึ่งนำมาใช้เป็นแบลงค์ในการวัดซีโอดี และเมื่อมีการทดลองซ้ำ Q<sub>1</sub> มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.34 คูลอมบ์ และ Q<sub>2</sub> ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.24 คูลอมบ์ และเมื่อทำการทดสอบข้อมูล ทางสถิติ พบว่า ค่าเฉลี่ยของ Q ที่ได้จากการใช้ซิงค์ออกไซด์ทั้งสองแผ่น ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังรูปที่ 4.74



รูปที่ 4.74 พื้นที่ใต้กราฟของสารละลายอิเล็กโทรไลต์โซเดียมซัลเฟต 0.1 โมลาร์ โดยเพิ่มปริมาตรน้ำตัวอย่างครั้งละ 0.5 มิลลิลิตร ในการวัดแต่ละรอบ จ่ายความต่างศักย์ 0.2 โวลต์ ไปยังตัวเร่งปฏิริยาซิงค์ออกไซด์

จากนั้นทำการวัดดังเดิมในสารละลายอิเล็กโทรไลต์โซเดียมซัลเฟต 0.1 โมลาร์ ที่มีสารละลายกลูโคส โดยทำการเติมสารละลายที่มีความเข้มข้นของซีโอดีทีละ 0.5 มิลลิลิตร ความเข้มข้นตั้งแต่ 0-200 มิลลิกรัมต่อลิตร ในการวัดแต่ละรอบ ๆ ละ 1 นาที พบว่า พื้นที่ใต้กราฟสูงขึ้นเมื่อความเข้มข้นของซีโอ ดีสูงขึ้น และเมื่อคำนวณพื้นที่ใต้กราฟต่อปริมาตรน้ำ พบว่าพื้นที่ใต้กราฟกลับลดลง ซึ่งในความเป็นจริง พื้นที่ใต้กราฟที่ได้ควรมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกัน ดังรูปที่ 4.75 และเมื่อมีการทดลองซ้ำข้อมูลที่ได้ก็ มีค่าไม่เท่ากัน (n=2)




รูปที่ 4.75 พื้นที่ใต้กราฟของซีโอดี<mark>ค</mark>วามเข้มข้นตั้งแต่ 0-200 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยเพิ่มปริมาตรน<mark>้ำตัว</mark>อย่างครั้ง<mark>ละ</mark> 0.5 มิลลิลิตร ในการวัดแต่ละรอบ จ่ายความต่างศักย์ 0.2 โวลต์ ไปยังตัวเร่งปฏิริยาซิงค์ออกไซด์

และเมื่อทำการวัดดังเดิมในสารละลายอิเล็กโทรไลต์โซเดียมซัลเฟต 0.1 โมลาร์ ที่มีสารละลาย กลูโคสเมื่อคำนวณในรูปของซีโอดีความเข้มข้นตั้งแต่ 0-200 มิลลิกรัมต่อลิตร ในการวัดแต่ละรอบ ๆ ละ 1 นาที แต่เพิ่มความต่างศักย์ที่จ่ายให้กับตัวเร่งปฏิริยาซิงค์ออกไซด์เป็น 0.5 โวลต์ พบว่า แนวโน้มเป็นไป ในทิศทางเดียวกันกับการจ่ายความต่างศักย์ที่ 0.2 โวลต์ คือพื้นที่ใต้กราฟสูงขึ้นเมื่อความเข้มข้นของซีโอ ดีสูงขึ้น และเมื่อคำนวณพื้นที่ใต้กราฟต่อปริมาตรน้ำ พบว่าพื้นที่ใต้กราฟกลับลดลง แต่มีพื้นที่ใต้กราฟ เพิ่มขึ้น ดังรูปที่ 4.76





รูปที่ 4.76 พื้นที่ใต้กราฟของซีโ<mark>อดี</mark>ความเข้ม<mark>ข้น</mark>ตั้งแต่ 0-200 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยที่ไม่มีการเคลื่อนย้ายตำแหน่งอุปกรณ์ในการวัด จ่ายความต่าง<mark>ศักย์</mark> 0.5 โวลต์ ไปยังตัว<mark>เร่ง</mark>ปฏิริยาซิงค์ออกไซด์

4.2.8.2.4 ตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำและความเสถียรของวิธีการ หาค่าซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสโดยใช้ซิ่งค์ออกไซด์ที่สปัตเตอริง 480 นาที เป็น ตัวเร่งปฏิกิริยา

1) ทำการวิเคราะห์หาค่าซีโอดีด้วยกระบวนการ โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส (COD<sub>PEC</sub>) ของ KHP ที่ความเข้มข้นที่ต่าง ๆ

นำตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ที่ทำการ

สังเคราะห์ด้วยวิธีการสปัตเตอริงเป็นเวลา 480 นาที ขนาด 0.5×0.5 ตารางเซนติเมตร บนแคปตอนเทป ที่เคลือบด้วยทองแดง มาทำการวัดซีโอดีของสารละลาย KHP ความเข้มข้นซีโอดีตั้งแต่ 0-500 มิลลิกรัม ต่อลิตร (ทุกความเข้มข้นของซีโอดีใช้ซิงค์ออกไซด์แผ่นเดิมในการวัด) ความเข้มข้นของสารอิเล็กโทรไลต์ โซเดียมซัลเฟต 0.1 โมลาร์ ปริมาตรน้ำ 3 มิลลิลิตร ระยะเวลาที่ใช้ในการหาค่าซีโอดี 1 นาที จ่ายความ ต่างศักย์ที่ 0.5 โวลต์ จะได้กราฟ ดังรูปที่ 4.77 พบว่า กระแสไฟฟ้าที่ได้จากการวัดในบางความเข้มข้น ยังต่ำกว่า Blank ซึ่งเป็นสารอิเล็กโทรไลต์โซเดียมซัลเฟต 0.1 โมลาร์ ที่ไม่มี KHP ผสมอยู่ และในการวัด ซีโอดีจากซิงค์ออกไซด์ทั้งสองแผ่นเมื่อนำกระแสไฟฟ้าที่วัดได้มาอินทริเกรตพื้นที่ใต้กราฟ (Q) ดังตาราง ที่ 4.23 จะเห็นได้ว่า Q ที่ความเข้มข้นเดียวกันยังคงแตกต่างกัน



รูปที่ 4.77 การวัดซีโอดีจ<mark>ากก</mark>ระบวนก<mark>ารโ</mark>ฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส ความเข้มข้นซีโอดีของ KHP 0-<mark>1</mark>50 มิลิกรัมต่อลิตร

ตารางที่ 4.23 พื้นที่ใต้กราฟของการวัดซีโอดีที่ความเข้มข้นต่าง ๆ

ซีโอดี	Q (คูลอมบ์)			
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 🍃	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2		
0	1.72021	1.69769		
10	1.63574	1.72627		
20	1.63574	1.51215		
50	1.64343	1.71321		
100	Enac 1.62219	1.48641		
200	1.44848	1.76161		
500	1.89693	1.98641		

## 2) ทำการวิเคราะห์หาค่าซีโอดีด้วยกระบวนการ โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส (COD<sub>PEC</sub>) ของกลูโคสที่ความเข้มข้นเดียวกัน

จากนั้นทำการทดสอบความเสถียรของตัวเร่งปฏิกิริยา

โดยการใช้ซิงค์ออกไซด์แผ่นเดิมวัดซีโอดีของ KHP ที่ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยทำการวัดซ้ำ เป็นจำนวน5 ซ้ำ แต่ละซ้ำใช้เวลาในการวัด 1 นาทีแล้วคำนวณพื้นที่ใต้กราฟ พบว่า มีบางซ้ำที่พื้นที่ใต้ กราฟจากการวัดซีโอดีที่ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ยังคงมีค่าต่ำว่า Blank และเมื่อทำการเปลี่ยน แผ่นใหม่แล้วทำการวัดดังเดิมก็พบว่า พื้นที่ใต้กราฟจากการวัดซีโอดีของซิงค์ออกไซด์คนละแผ่นก็ยังคงมี ค่าไม่เท่ากัน ดังตารางที่ 4.24

	ซิงค์ออกไซด์แผ่นที่					
ครั้งที่	1		2			
	Q <sub>b</sub>	Q <sub>total</sub>	Qb	$Q_{total}$		
1	1.66629	1.66117	1.75199	1.47133		
2	1.37062	1.33711	1.44971	1.60330		
3	1.49937	1.3 <mark>70</mark> 59	1.50851	1.61479		
4	1.47101	1.4 <mark>54</mark> 53	1.62353	1.72170		
5	1.41319	1.3 <mark>0308</mark>	1.61068	1.60744		
ค่าเฉลี่ย	1.48410	1.42530	1.58888	1.60371		
S.D.	0.11	0.14	0.12	0.09		

ตารางที่ 4.24 พื้นที่ใต้กราฟของการวัดซีโอดีที่ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

#### 4.2.8.2.5

#### หลังวัดซีโอดี

ซิงค์ออกไซด์ที่ผ่า<mark>นกา</mark>รสปัตเตอริงเป็นเวลา 480 นาที มี

<mark>เป</mark>รียบเทียบ<mark>ภาพ</mark>ถ่าย FESEM ของซิงค์ออกไซด์ก่อนและ

ความหนาเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วง 600-1,200 นาโนเมตร และจากการคาดการณ์ที่ว่าความหนาที่เพิ่มขึ้นนี้จะ ช่วยทำให้การวัดค่าซีโอดีมีความเสถียรขึ้นและลดสัญญาณรบกวนของกระแสไฟฟ้าเมื่อทำการวัดน้ำ ตัวอย่าง blank ที่มีเฉพาะสารอิเล็กโทรไลต์ และน้ำตัวอย่างที่มีสารอิเล็กโทรไลต์และสารให้ค่าซีโอดีผสมอยู่ ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ จึงทำการศึกษาลักษณะทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลงไปของซิงค์ออกไซด์ โดยนำ ซิงค์ออกไซด์ที่ผ่านการใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการวัดซีโอดีเปรียบเทียบกับภาพถ่าย FESEM ของ ซิงค์ออกไซด์ที่ผ่านการวัดซีโอดี ดังรูปที่ 4.78 พบว่า ซิงค์ออกไซด์ที่ผ่านการการวัดซีโอดีมีลักษณะ สัณฐานวิทยาที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เป็นทรงกลมกลายเป็นผลึกแบน ๆ และเมื่อเปรียบเทียบ ภาพถ่ายตัดขวาง (cross section) พบว่า ความหนาของซิงค์ออกไซด์ลดลงถึงครึ่งหนึ่งของความหนาเดิม และข้อมูลจากโหมด EDS ดังรูปที่ 4.79 พบว่า ซิงค์ออกไซด์หลังการถูกนำไปวัดค่าซีโอดีมีความ สอดคล้องกัน คือมีการลดลงของซิงค์ที่อยู่บนฐานรองรับ นอกจากนั้นยังพบพีคของโซเดียม (Na) ซัลเฟอร์ (S) และโปแทสเซียม (K) ซึ่งเป็นองค์ประกอบของสารละลายโซเดียมซัลเฟส (Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) และ โพแทสเซียมไฮโดรเจนพลาเลต (KHP) ที่ใช้ในการทดลองด้วย



รูปที่ 4.78 ภาพถ่าย FESEM ของซิงค์ออกไ<mark>ซด์เ</mark>ปรียบเทีย<mark>บก่อ</mark>นและหลังใช้วัดซีโอดี ก) ก่อนใช้วัดซีโอดี ข) หลังใช้วัดซีโอดี ค) ภา<mark>พตัด</mark>ขวางก่อนใช้วัดซี<mark>โอดี</mark> ง) ภาพตัดขวางหลังใช้วัดซีโอดี



รูปที่ 4.79 แสดง EDS สเปกตรัม ของซิงค์ออกไซด์หลังนำไปวัดซีโอดี

จากการทดลองในส่วนของผลการวัดซีโอดี พบว่า ค่าซีโอดียังไม่มีความแม่นยำ ในการวัด และในการวัดซีโอดีบางครั้งมีค่าต่ำกว่า Blank ซึ่งเกิดจากการที่ซิงค์ออกไซด์ที่นำมาทำการวัดซี โอดีไม่เสถียร เนื่องจากลักษณะสัณฐานวิทยาของซิงค์ออกไซด์มีการเปลี่ยนแปลงและความหนาลดลง หลังใช้วัดซีโอดี นอกจากนี้แล้วได้ทำการยืนยันผลการทดลองเพิ่มเติมโดยนำน้ำเสียที่ผ่านการวัดค่าซีโอดี ไปทำการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง ICP-MS เพื่อดูว่ามีการหลุดลอกของซิงค์ออกไซด์ในน้ำตัวอย่างหรือไม่

### 4.2.8.2.6 วิเคราะห์หาซิงค์และทองแดงในน้ำเสียที่ผ่านการวัด ค่าซีโอดีด้วยด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส (COD<sub>PEC</sub>) ด้วยเครื่อง ICP-MS นำน้ำเสียที่ผ่านการวัดค่าซีโอดีด้วยกระบวนการ

โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส โดยใช้ซิงค์ออกไซด์ที่ผ่านการสปัตเตอริงที่เวลา 120 นาที (ขนาด 1.0x1.0 ตารางเซนติเมตร) และ 480 นาที (ขนาด 0.5x0.5 ตารางเซนติเมตร) บนโพลิไอมายด์ฟิล์มที่เคลือบ ด้วยทองแดงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ไปทำการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง ICP-MS เพื่อหาปริมาณซิงค์ ซึ่งเป็นธาตุ องค์ประกอบของซิงค์ออกไซด์ และทองแดงซึ่งเป็นฐานรองรับของซิงค์ออกไซด์ เพื่อตรวจสอบดูว่า วัสดุที่ นำมาใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการวัดค่าซีโอดีนั้นมีความเสถียรหรือไม่ จากผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง ICP-MS พบว่า ในน้ำตัวอย่างมีซิงค์และทองแดง แสดงดังตารางที่ 4.25 โดยที่ 1) ซิงค์ออกไซด์ที่ผ่านกา รสปัตเตอริงที่เวลา 120 นาที (ขนาด 1.0x1.0 ตารางเซนติเมตร) พบซิงค์และทองแดงในน้ำตัวอย่าง 620 และ 480.9 ไมโครกรัมต่อลิตร ตามลำดับ และ 2) ซิงค์ออกไซด์ที่ผ่านการสปัตเตอริงที่เวลา 480 นาที (ขนาด 0.5x0.5 ตารางเซนติเมตร) พบซิงค์และทองแดงทำให้พื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อการวัดซีโอดี ทำให้ค่าซีโอดีที่ทำการวัดซ้ำมีค่าไม่เท่ากัน และในบางครั้งมีค่าต่ำกว่า blank

ระยะเวลาในการสปัตเตอริงซิงค์ออกไซด์						
12	0 นาที	480 นาที				
Zn (ppb)	Cu (ppb)	Zn (ppb)	Cu (ppb)			
620.0	480.9	160.6	602.2			

			2		
a. v	2 9	6	9 0 0	1 41	2 <u>4</u> 5 <u>4</u>
ตารา.๚/ 1 25 คาายเญย	1019 101 ର. 961.96	<u> </u>	ໄງທາສາລ	ยางหม่ายางเกา	าราดต์ โลด้
1 1 1 1 N VI 4.2 J 1 1 3 1616 UA	10800101	LIPPPIO LIGNPPLI	1919191119196		19 9AL OPENAL

าสยเทคเนเลง

# บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

### 5.1 ไทเทเนียมไดออกไซด์

### 5.1.1 สรุปผลการศึกษา

การศึกษาในครั้งนี้เพื่อศึกษาหาสภาวะการสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยวิธีแอ โนไดเซซันแบบพัลส์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา จากนั้นนำมาใช้ในกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสเพื่อ นำมาหาค่าซีโอดี โดยทำการเปรียบเทียบกับซีโอดีทางทฤษฎีที่เตรียมขึ้นจากสารละลายมาตรฐาน กลูโคสและสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลท สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

5.1.1.1 ผลการศึกษาการสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์รูปท่อด้วยกระบวนการ แอโนไดเซซันแบบพัลส์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

 สังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยกระบวนการแอ โนไดเซซันแบบพัลส์ที่สภาวะการสังเคราะห์ต่าง ๆ ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ 0.30 โมลาร์ ของ แอมโมเนียมฟลูออไรด์ ผสมด้วยกลีเซอรอลและน้ำในอัตราส่วน 60 : 40 ใช้ระยะเวลาสังเคราะห์ ทั้งหมด 3 ชั่วโมง เมื่อนำมาตรวจลักษณะสัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (FESEM) พบว่าทุกสภาวะการทดลองเกิดออกไซด์ทั่วทั้งพื้นผิว มีลักษณะเป็นรูปท่อ แต่ยังท่อที่ได้ยังมี ความสูงต่ำที่ไม่สม่ำเสมอกัน รวมถังผนังท่อที่ขาดและเชื่อมติดกัน ซึ่งไม่เหมาะที่จะนำมาใช้เป็น ตัวเร่งปฏิกิริยา

 การทดลองสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วย กระบวนการแอโนไดเซซันแบบพัลส์ โดยลดระยะเวลาสังเคราะห์ทั้งหมดจาก 3 ชั่วโมงลง เป็น 0.5 1 และ 1.5 ชั่วโมง เมื่อนำไปส่องกล้อง FESEM พบว่าได้ลักษณะออกไซด์รูปท่อที่มีความสูงสม่ำเสมอกัน มากขึ้น รวมถึงขนาดท่อที่ได้นั้นมีขนาดใกล้เคียงกันมากกว่าระยะเวลาการสังเคราะห์ 3 ชั่วโมง

 สึกษาความหนาของออกไซด์ด้วยกล้อง FIB-FESEM ของ ตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการแอโนไดซ์แบบพัลส์ ซึ่งเมื่อ เปรียบเทียบระยะเวลาที่ใช้การสังเคราะห์ทั้งหมดคือ 0.5 1 1.5 และ 3 ชั่วโมง พบว่าความหนาของชั้น ออกไซด์จะเพิ่มมากขึ้นตามระยะเวลาการสังเคราะห์ที่ใช้มากขึ้น

4) ศึกษาการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีแสง เพื่อวัดความสามารถใน การปลดปล่อยอิเล็กตรอนของตัวเร่งปฏิกิริยาเมื่อได้รับการกระตุ้นด้วยแสง โดยทำการเปรียบเทียบ ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ผ่านการแอโนไซเซซันแบบพัลส์พบว่า สภาวะที่ให้ Photocurrent density มากที่สุด คือ 20 โวลต์ 5 นาที / -5 โวลต์ 5 วินาที ที่ระยะเวลาการสังเคราะห์ 3 ชั่วโมง แต่เมื่อ เปรียบเทียบเพียงแค่ระยะเวลาการสังเคราะห์ทั้งหมด พบว่าที่ระยะเวลาสังเคราะห์ 1.5 ชั่วโมงนั้นให้ Photocurrent density ที่มากกว่าระยะเวลาการสังเคราะห์อื่น ๆ จึงเลือกสภาวะการสังเคราะห์ 20 โวลต์ 5 นาที / -5 โวลต์ 5 วินาที ใช้ระยะเวลาการสังเคราะห์ทั้งหมด 1.5 ชั่วโมง เป็นสภาวะที่ เหมาะสม และนำไปใช้ในทุก ๆ การทดลองถัดไป

5) ด้านการศึกษาโครงสร้างผลึกของออกไซด์พบว่าไทเทเนียมได ออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้เป็นโครงสร้างผลึกแบบอนาเทส ที่มีแผ่นไทเทเนียมเป็นสารตั้งต้น (Substrate) และมีการตอบสนองต่อแสงในช่วงรังสียูวี (190 – 360 นาโนเมตร) 5.1.1.2 ผลการศึกษาการใช้กระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสในการวัดค่าซีโอดี โดยใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์รูปท่อที่เตรียมด้วยกระบวนแอโนไดเซซันแบบพัลส์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

 จากการหาค่าซีโอดีด้วยการบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสโดย ใช้ชุดการทดลองที่ 1 เกิดปัญหาคือกราฟกระแสไฟฟ้าที่วัดได้ออกมาจากทั้งแบลงค์และสารละลาย มาตรฐานกลูโคสที่ความเข้มข้นต่าง ๆ นั้นเป็นเส้นเดียวกัน ซึ่งไม่สามารถนำมาหาคำนวณหาค่าซีโอดีได้ โดยสันนิษฐานว่า อาจเกิดจากการที่ไม่ได้ใช้หัวหนีบปากจระเข้คืบที่ขั้วใช้งาน (Working electrode) และขั้วไฟฟ้าช่วย (Counter electrode) โดยตรง

 สภาวะต่าง ๆ ที่เหมาะสมสำหรับการหาค่าซีโอดีด้วยการบวนการโฟ โตอิเล็กโตรคะตะไลซิส ใช้สารละลายโซเดียมซัลเฟต (Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) 0.1 โมลร์ เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ขั้วร่วมไฟฟ้าที่ใช้ คือ แพลทินัมทตินัม ทำการจ่ายความต่างศักย์เท่ากับ 0.5 โวลต์ ปริมาตรที่ใช้ในการ ทดลอง 3 มิลลิลิตร นอกจากนี้จะต้องทำการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์ 1 แผ่น ต่อ 1 ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน โดยห้ามคืบสายไฟใหม่ ซึ่งหากทำการเปลี่ยนน้ำตัวอย่างจะใช้ Dropper ในการดูดน้ำออก (คืบสายไฟใหม่ได้ต่อเมื่อเปลี่ยนตัวเร่งปฏิกิริยาแผ่นใหม่)

3) การหาค่าซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสโดยใช้ ไทเทเนียมไดออกไซด์รูปท่อที่เตรียมด้วยกระบวนแอโนไดเซซันแบบพัลส์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยานั้นได้ทำการ สร้างกราฟมาตรฐานขึ้นมา โดยใช้สารละลา<mark>ยมาตรฐานโพแท</mark>สเซียมไฮโดรเจนพทาเลท (KHP) 11 ความ

เข้มข้น ซึ่งได้ค่า R<sup>2</sup> = 0.9742 ในช่วงสารละลายมาตรฐานความเข้มข้น 20 – 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 4) ตัวเร่งปฏิกิริยาที่สังเคราะห์ได้เมื่อทดลองซ้ำที่ความเข้มข้นของ สารละลายมาตรฐานเดิม พบว่าได้ค่าพื้นที่ใต้กราฟที่ไม่เท่ากัน อาจะเพราะตัวเร่งปฏิกิริยาที่สังเคราะห์ ได้นั้นยังไม่มีความเสถียรมากพอ

#### 5.1.2 ข้อเสนอแนะ

 ในการวัดกระแสด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสควรใช้เครื่องมือที่ เป็นที่เหมาะสมและเสถียรในการวัดข้อมูล เพื่อป้องกันการเก็บข้อมูลที่ผิดพลาด

 พื้นที่ผิวตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ส่งผลต่อการวัดค่าซีโอดีมาก ซึ่งควรกำหนดพื้นที่ ผิวตัวเร่งปฏิกิริยาให้เหมาะสมกับปริมาตรน้ำที่ใช้ในการทดลอง หรืออีกแนวทางคือลดปริมาตรน้ำให้ น้อยลงหากพื้นที่ผิวตัวเร่งปฏิกิริยามีจำกัด

### 5.2 ซิงค์ออกไซด์

### 5.2.1 สรุปผลการศึกษา

1)

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการสัเงคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ ด้วยวิธีการแอโนไดเซชันและวิธีการสปัตเตอริง แล้วนำมาใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการ โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสเพื่อวัดซีโอดีในน้ำเสีย ซึ่งอาศัยกฏการแยกสารด้วยไฟฟ้าของฟาราเดย์ Faraday' law) มาใช้หาความเข้มข้นเมื่อสารอินทรีย์ถูกออกซิไดซ์ ทำการศึกษาความถูกต้องแม่นยำ และความเสถียรของวิธีการโดยเปรียบเทียบกับค่าซีโอดีจากการคำนวณในทางทฤษฎีและการวิเคราะห์ ซีโอดีด้วยวิธีมาตรฐานไดโครเมต ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน จากการศึกษาสามารถสรุปผล การศึกษา ได้ดังนี้

### 5.2.1.1 ผลการศึกษาการสังเคราะห์ชิงค์ออกไซด์ด้วยกระบวนการแอโนไดเซชัน

จากการสังเคร<mark>าะ</mark>ห์ซิงค์ออกไซด์ด้วยกระบวนการแอโนไดเซชันใน

สารละลายโซเดียมซัลเฟต ความเข้มข้น 0.2 โมลาร์ โดยในตอนแรกทำการศึกษาสภาวะที่ใช้ในการแอโน ไดซ์ที่แตกต่างกัน คือ จ่ายความต่างศักย์ 1 3 5 10 และ 20 โวลต์ เป็นเวลา 5 10 30 นาที พบว่า การ จ่ายความต่างศักย์ที่ 20 โวลต์ ในระยะเวลาเพียง 5 นาที ทำให้สารละลายอิเล็กโทรไลต์เกิด ความร้อนและเดือด ส่งผลให้แผ่นซิงค์ละลายจนเสียรูป ส่วนที่สภาวะอื่น ๆ เมื่อตรวจสอบลักษณะ พื้นผิวด้วย FESEM จะพบว่ามีลักษณะสัณฐานวิทยาเป็นผลึกรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ขนาดนาโนเมตรขึ้นกระจัดกระจายกันทั่วทั้งแผ่น โดยที่ขนาดของผลึกจะใหญ่ขึ้นและชัดเจนขึ้นเมื่อใช้ ระยะเวลาการแอโนไดซ์ที่นานขึ้น ยกเว้นการจ่ายความต่างศักย์ที่ 10 โวลต์ ลักษณะ สัณฐานวิทยาจะเปลี่ยนแปลงไป โดยที่มีขั้นออกไซด์ทับถมกันจนหนาและเกิดรอยแยกขึ้นที่บนพื้นผิวของ ซิงค์ออกไซด์ และในภายหลังที่มีการเพิ่มระยะเวลาในการแอโนไดซ์เป็น 60 นาที และ 120 นาที สำหรับการจ่ายความต่างศักย์ที่ 3 โวลต์ ก็ยังคงพบว่าลักษณะสัณฐานวิทยาของซิงค์ออกไซด์ยังคงเป็น รูปทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอยู่ แต่ที่ 120 นาที แผ่นซิงค์ออกไซด์เริ่มเกิดการละลาย

2) การทดสอบความแข็งแรงของซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์จาก กระบวนการแอโนไดเซชัน โดยนำมาการเขย่าในน้ำ DI ด้วยเครื่องอัลตราโซนิค พบว่า น้ำ DI มีความขุ่น และซิงค์ออกไซด์มีการหลุดลอกจากการยืนยันโดยนำผงตะกอนในน้ำไปวิเคราะห์ด้วย FESEM

และขงคออกเขตมการหลุดลอกงากการขนอนเตอน แงรตะกอนเนนาเบรเคราะหตรย FESEM 3) จากการนำตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์แล้วไปอบที่ อุณหภูมิแตกต่างกัน เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิที่อบหลังจากการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา พบว่า การ อบที่ อุณหภูมิต่ำแผ่นซิงค์ออกไซด์ยังคงรูปเดิมและลักษณะสัณฐานวิทยาไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต่ ที่ 450 องศาเซลเซียส แผ่นซิงค์ออกไซด์เกิดการบิดงอเสียรูป

 จากการวิเคราะห์ความขรุขระของซิงค์ออกไซด์ด้วย AFM พบว่า การใช้เวลาในการแอโนไดซ์ที่นานขึ้นทำให้ขนาดผลึกสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีความ หนาของซิงค์ออกไซด์มากขึ้น ส่งผลให้พื้นผิวของซิงค์ออกไซด์มีความหยาบหรือมีพื้นผิวขรุขระมากขึ้นด้วย
จากการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกหรือเฟสที่เกิดบนพื้นผิวของซิงค์อ

อกไซด์ด้วย XRD พบว่า ซิงค์ออกไซด์มีลักษณะโครงสร้างแบบเฮกซะโกนอลเวอร์ไซด์ (hexagonal wurtzite structure) ขนาดและความสูงของพีคจะเพิ่มขึ้นเมื่อใช้ความต่างศักย์และระยะเวลาใน การแอโนไดซ์ที่นานขึ้น และยืนยันได้ว่าซิงค์ออกไซด์สามารถสังเคราะห์บนแผ่นซิงค์ได้ด้วยกระบวนการ แอโนไดเซชัน 6) วิเคราะห์การดูดกลืนแสงของซิงค์ออกไซด์ด้วย UV-Vis spectrophotometer พบว่า ซิงค์ออกไซด์สามารถดูดกลืนแสงได้ทั้งช่วงยูวีและวิสิเบิล และการดูดกลืน แสงลดลงเมื่อผ่านการแอโนไดซ์ที่ระยะเวลามากขึ้น เนื่องจากการใช้ระยะเวลาในการแอโนไดซ์ที่นานนั้น ทำให้ผลึกสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีขนาดใหญ่กว่าการใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่า ขนาดผลึกที่ใหญ่ทำให้เกิด สะท้อนแสงได้ดีกว่า

7) การวิเคราะห์การตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีด้วยแสงเป็นตัวแทนใน การวัดความสามารถของตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ที่จะนำไปใช้สำหรับกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส โดยเปรียบเทียบค่าความหน่าแน่นของกระแสไฟฟ้า (Photocurrent density) เมื่อได้รับการกระตุ้นจาก การฉายแสงไปยังตัวเร่งปฏิกิริยา ที่ความต่างศักย์ 0.4 โวลต์ พบว่า การฉายแสงไปยังตัวเร่งปฏิกิริยามี Photocurrent densityสูงกว่าการไม่ฉายแสงประมาณ 1.3 เท่า จากผลของการแอโนไดซ์ 3 โวลต์ ที่ ระยะเวลาใช้แตกต่างกัน คือ 5 นาที 10 นาที 30 นาที 60 นาที พบว่า การใช้ระยะเวลาในการแอโนไดซ์ที่ นานขึ้นทำให้เกิดอิเล็กตรอนที่พื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยามากขึ้น เท่ากับ 55.481 188.951 189.535 และ 201.333 มิลลิแอมแปร์ต่อตารางเซนติเมตร ตามลำดับ จากผลการแอโนไดซ์ที่จ่ายความต่างศักย์ 1 โวลต์ 3 โวลต์ 5 โวลต์ และ 10 โวลต์ ระยะเวลา 30 นาทีเท่ากัน มี Photocurrent density สูงขึ้นเท่ากับ 71.564 189.535 198.019 และ 223.185 มิลลิแอมแปร์ต่อตารางเซนติเมตร ตามลำดับ และเมื่อกระตุ้น ด้วยแสงต่างชนิดกัน พบว่า แผ่นซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ขึ้นนั้นตอบสนองต่อแสงยูวีได้ดีกว่าแสงวิสิเบิล Photocurrent density เท่ากับ 201.333 และ 357.049 มิลลิแอมแปร์ต่อตารางเซนติเมตร

Photocourent density in ino 201.555 และ 557.049 มถุลแอมแบวตอตาว เจเชนตเมตร 8) จากการวัดการตอบสนองต่อแสงของตัวเร่งปฏิกิริยาโดยการวัดสลับ การปิด-เปิดสวิตซ์ไฟ พบว่า กระแสไฟฟ้าที่วัดได้เมื่อปิดไฟมีค่าต่ำ แต่เมื่อทำการเปิดสวิตซ์ไฟ กระแสไฟฟ้าก็จะมีค่าสูงขึ้นเนื่องจากแสงเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนบนพื้นผิว ตัวเร่งปฏิกิริยาได้ดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตาม กระแสไฟฟ้าที่วัดได้จะมีค่าสูงขึ้นเรื่อย ๆ สันนิษฐานว่าอาจเกิด เนื่องมาจากตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ขึ้นด้วยกระบวนการแอโนไดเซชันนั้นมีความไม่ เสถียร

# 5.2.1.2 ผลก<mark>ารศึกษาการใช้กระบวนการโฟโตอิ</mark>เล็กโตรคะตะไลซิสในการวัด

ค่าซีโอดีโดยใช้ซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์จากกระบวนการแอโนไดซเซชันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
ถ้วยคุณลักษณะของซิงค์ออกไซด์ที่ศึกษาจึงเลือกซิงค์ออกไซด์ที่ศึกษาจึงเลือกซิงค์ออกไซด์ที่ผ่าน
การแอโนไดซ์โดยจ่ายความต่างศักย์คงที่ 3 โวลต์ ระยะเวลา 60 นาที เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการ
วิเคราะห์หาซีโอดีในน้ำเสีย และจากการวัดค่าซีโอดีด้วยเครื่องวัดที่สร้างขึ้น โดยวัดซีโอดีของกลูโคสที่
ความเข้มข้น 10 100 และ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า ว่า Iph (total) ของน้ำตัวอย่างที่มีสารอินทรีย์ไม่
สามารถลดลงจนถึงระดับเดียวกันกับ Iph (blank) ในระยะเวลา 2 นาที นั่นหมายถึงสารอินทรีย์ไม่ถูกออกซิไดซ์
ได้จนหมด จึงสร้างถึงปฏิกรณ์ขึ้นใหม่เพื่อลดปริมาณน้ำตัวอย่างในการวัดซีโอดี จากนั้นจึงศึกษาโดยแปรผัน
ความเข้มข้นของสารอิเล็กโทรไลต์ที่ความเข้มข้นต่างกัน พบว่า การตอบสนองของกระแสไฟฟ้าที่วัดได้ลดลง
เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารอิเล็กโทรไลต์ที่ความเข้มข้นต่างกัน พบว่า การตอบสนองของกระแสไฟฟ้าที่วัดได้ลดลง
เมื่อเข้มข้นของสารอิเล็กโทรไลต์ที่ความเข้มข้นต่างกัน พบว่า การตอบสนองของกระแสไฟฟ้าที่วัดได้ลดลง
เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารอิเล็กโทรไลต์ โดยที่ความเข้มข้นต่างกัน พบว่า การตอบสนองของกระแสไฟฟ้าที่วัดได้ลดลง
เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารอิเล็กโทรไลต์ โดยที่ความเข้มข้น 0.1 0.5 และ 1.0 โมลาร์ กระแสที่วัดได้อยู่
ในช่วง 300-350 200-250 และ 150-200 มิลลิแอมแปร์ ตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตามกระแสไฟฟ้าที่วัดซ้ำใน
แต่ละความเข้มข้นยังคงไม่ใกล้เคียงกัน และเมื่อทำการแปรผันความต่างศักย์ คือ 0.5 โวลต์ 1 โวลต์ และ
1.5 โวลต์ พบว่า การจ่ายความต่างศักย์ที่มากขึ้นทำให้กระแสไฟฟ้าที่วัดได้สูงขึ้น แต่หากทำการจ่ายความ
ต่างศักย์ที่มากขึ้นทำให้กระแสไฟฟ้าที่วัดได้สูงขึ้น แต่หากทำการจ่ายความ

2) จากการวัดค่าซีโอดีด้วยเครื่องโพเทนซิโอสแตทเพื่อตรวจสอบความ ถูกต้องของเครื่องมือวัดซีโอดีที่สร้างขึ้น พบว่า สารอินทรีย์ก็ยังคงย่อยไม่หมดแม้ว่าจะเพิ่มระยะเวลาใน การวัดซีโอดีจาก 2 นาที เป็น 5 นาที และชุดข้อมูลกระแสที่วัดได้มีค่าแกว่ง ไม่คงที่ซึ่งมีแนวโน้มที่จะสูง เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อใช้ระยะเวลาในการวัดซีโอดีมากขึ้น เนื่องมาจากความไม่เสถียรของซิงค์ออกไซด์ที่ สังเคราะห์ด้วยวิธีแอโนไดเซชันจึงทำการเปลี่ยนวิธีการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นวิธีสปัตเตอริงแทน

5.2.1.3 ผลการศึกษาการสังเคราะห์ซิงค์ออกไซด์ด้วยกระบวนการสปัตเตอริง 1) จากการนำตัวเร่งปฏิกิริยาที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการสปัตเตอริงที่ ระยะเวลา 30 และ 120 นาที บนฐานรองรับพลาสติก PET ที่เคลือบด้วยไทเทเนียมและเงิน ทำการศึกษาความเป็นผลึกและเฟสด้วย XRD พบเพียงพีคของ PET ซึ่งเป็นฐานรองรับเนื่องจาก ซิงค์ออกไซด์มีขนาดบางมาก จึงนำไปวิเคราะห์ด้วย XPS แทน จึงระบุได้ว่ามีซิงค์ออกไซด์บนฐานรองรับ เนื่องจากพบพีค Binding energy = Zn2p และ O1s แต่เมื่อนำซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้ไปทำการ วัดซีโอดี พบว่า ซิงค์ออกไซด์รวมทั้งเงินและอินเดียมทินออกไซด์มีการหลุดลอกออกจากพลาสติก PET ไม่เหมาะสำหรับนำมาวัดค่าซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส จึงทำการเปลี่ยนชนิดของ ฐานรองรับเป็นโพลิไอมายด์ฟิล์มที่เคลือบด้วยทองแดงแทน

2) จากการนำตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์วิธีการสปัตเต อริง เป็นเวลา 60 120 240 และ 480 นาที บนโพลิไอมายด์ฟิล์มที่เคลือบด้วยทองแดง ทำการศึกษา ลักษณะพื้นผิวด้วย FESEM พบว่า มีลักษณะสัณฐานเป็นทรงกลมเมื่อใช้เวลาสปัเตอริงที่ 60 นาที เป็น ผลึกเมื่อใช้เวลา 120 และ 240 นาที และลักษณะสัณฐานวิทยาที่เป็นทรงกลมมีรูตรงกลางคล้ายลำไย ถูกคว้านเมล็ด เมื่อใช้เวลา 480 นาที มีโครงสร้างขนาดระดับนาโนเมตร โดยที่ขนาดใหญ่ขึ้นตาม ระยะเวลาที่ใช้สปัตเตอริง

3) ผลของ FESEM มีความสอดคล้องกับการวิเคราะห์องค์ประกอบของ ธาตุที่มีอยู่ในตัวอย่างโดยใช้ FESEM ในโหมด EDS พบว่า ระยะเวลาในการสปัตเตอริงที่ 60 นาที มีพีคของ ซิงค์และออกซิเจนเกิดขึ้น คิดเป็น 25.98% และ 19.15% ตามลำดับ เมื่อเพิ่มเวลาในการสปัตเตอริง เป็น 120 นาที 240 และ 480 นาที ซิงค์เพิ่มขึ้นเป็น 33.49% 53.66% และ 75.71% ตามลำดับ และ ออกซิเจนเพิ่มขึ้นเป็น 7.53% 13.88% และ 21.20% ตามลำดับ สรุปได้ว่าจะมีซิงค์ออกไซด์เพิ่มมากขึ้น เมื่อใช้เวลาในการสปัตเตอริงนานขึ้น

 4) ผลของการศึกษาความหนาด้วยเครื่อง Optical profiler พบว่า เมื่อ ใช้ระยะเวลาในการสปัตเตอริงที่นานขึ้นนอกจากจะทำให้ซิงค์ออกไซด์มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วยังทำให้ความ หนาของซิงค์ออกไซด์เพิ่มขึ้นด้วย โดยที่ 120 นาที 240 และ 480 นาที มีความหนา 200-400 400-600 และ 600-1,200 นาโนเมตร ตามลำดับ ส่วนที่ระยะเวลา 60 นาที ไม่สามารถวัดความหนาได้ด้วย เครื่องมือนี้เนื่องจากซิงค์ออกไซด์ค่อนข้างบาง

5) ผลวิเคราะห์การดูดกลืนแสงของซิงค์ออกไซด์ด้วยเครื่อง UV-VIS spectrophotometer พบว่า ซิงค์ออกไซด์สามารถดูดกลืนแสงได้ดีในช่วงยูวี โดยที่การดูดกลืนแสงจะ เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ใช้ในการสปัตเตอริง อีกทั้งยังสามารถดูดกลืนแสงในช่วงวิสิเบิลได้เพิ่มขึ้นด้วย ยกเว้นที่ 60 นาที ที่การดูดกลืนแสงมีค่าสูงที่สุด

6) จากการวัดการตอบสนองต่อแสงของตัวเร่งปฏิกิริยาโดยการวัดสลับ การปิด-เปิดสวิตซ์ไฟ พบว่า การตอบสนองของตัวเร่งปฏิกิริยาในที่มืดเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยซึ่งจะไม่เกิด การออกซิเดชันทางเคมี แต่เมื่อมีการฉายแสงยูวีไปยังตัวเร่งปฏิกิริยา กระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการวัดการ ตอบสนองต่อแสงมีค่าสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่าซิงค์ออกไซด์สามารถตอบสนองต่อแสงในช่วงยูวีได้ดี และ ยิ่งดีขึ้นเมื่อมีการจ่ายความต่างศักย์ไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม เมื่อทำการฉายไฟไปยังตัวเร่งปฏิกิริยาในเวลาที่ นานขึ้นกระแสที่วัดได้ลดลงประมาณ 10% ในทุก ๆ รอบของการวัด ในภายหลัง จึงได้ทำการปรับปรุงที่ แหล่งกำเนิดแสงโดยการเพิ่มพัดลมระบายอากาศเพื่อลดอุณหภูมิ พบว่า กระแสที่วัดได้ในแต่ละรอบมี ความเสถียรและใกล้เคียงกันมากขึ้น นอกจากนี้เมื่อทำการเปิดหลอดไฟตลอดการวัด แล้วทำการ ปิด-เปิดแหล่งจ่ายความต่างศักย์ไฟฟ้าสลับกันแทน พบว่า กระแสที่ได้ยิ่งมีความเสถียรและใกล้เคียงกัน มากขึ้น

### 5.2.1.4 ผลการศึกษาการใช้กระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสในการวัด ค่าซีโอดีโดยใช้ซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์จากกระบวนการสปัตเตอริงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

 จากการทดสอบความเสถียรของซิงค์ออกไซด์โดยการวัดซ้ำของ สารละลายอิเล็กโตรไลต์ด้วยเครื่องโพเทนชิโอสแตท พบว่าพื้นที่ใต้กราฟลดลงเมื่อทำการวัดซ้ำโดยใช้ซิ งค์ออกไซด์แผ่นเดิม Q<sub>1</sub> ถึง Q<sub>5</sub> เท่ากับ 9.83455 2.74006 1.32620 1.02387 และ 0.76696 คูลอมบ์ ตามลำดับ และเนื่องจากจุดจำนวนข้อมูลที่เก็บได้จากเครื่องโพเทนชิโอสแตทค่อนข้างน้อยจึงเปลี่ยนไป ใช้เครื่องมัลติมิเตอร์ในการวัดซีโอดี

2) การทดลองเบื้องต้นโดยนำตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ที่สปัตเตอริง เวลา 60 120 และ 240 นาที ทำการวัดซีโอดีของกลูโคสที่ความเข้มข้น 10 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร จ่าย ความต่างศักย์ 0.1 และ 0.2 โวลต์ พบว่า ในส่วนของการศึกษาการใช้ซิงค์ออกไซด์ที่สปัตเตอริงที่ระยะเวลา ต่างกันและการแปรผันความเข้มข้นของซีโอดียังไม่สามารถแปรผลจากข้อมูลได้ ส่วนการศึกษาส่วนของ การจ่ายความต่างศักย์ พบว่า การตอบสนองของกระแสมีค่าสูงขึ้นเมื่อจ่ายความต่างศักย์สูงขึ้น และเมื่อ ทดลองจ่ายความต่างศักย์ พบว่า การตอบสนองของกระแสมีค่าสูงขึ้นเมื่อจ่ายความต่างศักย์สูงขึ้น และเมื่อ ของก่ายความต่างศักย์เพิ่มจนถึง 1.0 โวลต์ การตอบสนองของกระแสก็ยังคงมีค่าสูงขึ้นเรื่อย ๆ แต่ อย่างไรก็ตามในการจ่ายความต่างศักย์เพื่อวัดซีโอดีควรจ่ายที่ความต่างศักย์ที่เหมาะสมสำหรับตัวเร่ง ปฏิกิริยาที่เลือกนำมาใช้งาน เนื่องจากการจ่ายความต่างศัยก์ที่สูงมากเกินจะทำให้ตัวเร่งปฏิกิริยาเกิดความ เสียหายได้

3) จากการเปรียบเทียบการใช้ชั้วไฟฟ้าร่วมต่างชนิดคือ แกรไฟต์และ แพลทินัมตทินัม เพื่อตรวจสอบดูว่าขั้วไฟฟ้าร่วมชนิดใดจะเป็นผู้ช่วยที่ดีในการส่งผ่านอิเล็กตรอนหรือ กระแสไปยังขั้วไฟฟ้าใช้งานได้ดีกว่า พบว่า ทั้งสองชนิดให้ผลไม่ต่างกัน แต่เนื่องจากการออกแบบ ถังปฏิกรณ์ต้องวางแกรไฟต์ในแนวนอนซึ่งมีโอกาสที่รอยต่อของขั้วมีโอกาสที่จะรั่วเมื่อโดนสารละลายจึง เปลี่ยนมาใช้แพลทินัมตทินัมเป็นขั้วไฟฟ้าร่วมแทน

 4) จากการใช้ซิงค์ออกไซด์ที่ผ่านการสปัตเตอริงเป็นเวลา 120 นาที วัด ซีโอดีที่ความเข้มข้น 0-500 มิลลิกรัมต่อลิตร ด้วยซิงค์ออกไซด์แผ่นเดิม ทำการวัดจากความเข้มข้นต่ำไป สูงและสูงไปต่ำสลับกัน พบว่า การวัดค่าซีโอดียังไม่มีความแม่นยำเท่าใดนัก ที่ความเข้มข้นเดียวกันค่าที่ วัดได้ไม่เท่ากัน และเมื่อสร้างกราฟมาตรฐานระหว่างค่า Q<sub>net</sub> กับความเข้มข้นของซีโอดีทางทฤษฎีของ สารละลายมาตรฐานกลูโคส โดยตัดข้อมูลบางค่า จะได้สมการเส้นตรง y = 0.05268x – 0.35567 และ R<sup>2</sup> = 0.9527 สำหรับการวัดซีโอดีจากความเข้มข้นต่ำไปสูง และ สำหรับการวัดซีโอดีจากความเข้มข้นสูงไป ต่ำ จะได้สมการเส้นตรง y = 0.0487x + 1.89939 และ R<sup>2</sup> = 0. 0.9099 5) จากการใช้ซิงค์ออกไซด์ที่ผ่านการสปัตเตอริงเป็นเวลา 120 นาที วัด ซีโอดีที่ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร วัดซ้ำด้วยซิงค์ออกไซด์แผ่นเดิม เมื่อคำนวณหาค่าซีโอดี พบว่าค่าที่ได้ใกล้เคียงกันและใกล้เคียงความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่เตรียมโดยคำนวณค่าซีโอดี ในทางทฤษฎี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 104.00 มิลลิกรัมต่อลิตร และ S.D. เท่ากับ 8.45

6) การใช้ซ้ำของตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ทำให้คุณภาพของซิงค์ออก ไซด์ลดลง พื้นที่ผิวบางส่วนถูกทำลายซึ่งส่งผลทำให้กระแสจากการวัดซีโอดีจากการใช้ซ้ำมีค่าต่ำลงจน บางครั้งการวัดกระแสของน้ำตัวอย่างที่มีสารอินทรีย์มีค่าต่ำกว่ากระแสของน้ำตัวอย่างที่มีเพียงสาร อิเล็กโทรไลต์ ค่าที่วัดได้จึงไม่มีความแม่นยำและไม่เสถียร

7) การเปลี่ยนที่ของตำแหน่งการใช้ปากคืบคืบที่ขั้วไฟฟ้าหรือการขยับ ตำแหน่งการวางขั้วไฟฟ้าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการวัดซีโอดี ทำให้กระแสที่วัดได้มีค่าเปลี่ยนแปลงไป แต่ ปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือความเสถียรของตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ ซึ่งจากผลของการ ทดลองการวัดซีโอดีโดยที่เพิ่มความเข้มข้นของซีโอดีของกลูโคสจาก 0-200 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยทำการ เติมสารละลายที่มีความเข้มข้นของซีโอดีทีละ 0.5 มิลลิลิตร ต่อการวัดที่ 1 ความเข้มข้น พบว่าพื้นที่ใต้ กราฟ (Q) จากการอินทริเกรตของของกระแสที่วัดได้มีแน้วโน้มที่จะสูงขึ้นเมื่อความเข้มข้นเพิ่มขึ้นแต่ ยังคงมีบางความเข้มข้นที่มีพื้นที่ใต้กราฟต่ำกว่าที่ควรเป็น และเมื่อนำพื้นที่ใต้กราฟหารด้วยปริมาณน้ำ ตัวอย่างกลับพบว่าค่าลดลงเมื่อความเข้มข้นเพิ่ม ซึ่งในความเป็นจริงควรเพิ่มขึ้นโดยแปรผันตรงกับ Q ที่ วัดได้

8) จากการคาดการณ์ที่ว่าความหนาของซิงค์ออกไซด์มีผลต่อการวัดค่า ซีโอดีโดยซิงค์ออกไซด์ที่หนามากกว่าจะช่วยทำให้การวัดค่าซีโอดีมีความเสถียรขึ้นและลดสัญญาณ รบกวนของกระแสไฟฟ้าเมื่อทำการวัดน้ำตัวอย่าง blank ที่มีเฉพาะสารอิเล็กโทรไลต์ และน้ำตัวอย่างที่มี สารอิเล็กโทรไลต์และสารให้ค่าซีโอดีผสมอยู่นั้นยังคงหาข้อสรุปไม่ได้ เนื่องจากได้ทำการทดลองใช้ซิงค์อ อกไซด์ที่เพิ่มเวลาในการสปัตเตอริงเป็น 480 นาที มาทำการวัดซีโอดีของ KHP พบว่า กระแสไฟฟ้าที่ได้จากการ วัดในบางความเข้มข้นยังต่ำกว่าแบลงค์ซึ่งเป็นสารอิเล็กโทรไลต์โซเดียมซัลเฟต 0.1 โมลาร์ ที่ไม่มี KHP ผสมอยู่ และเมื่อทำการวัดซ้ำที่ความเข้มข้นเดียวกันคือที่ 100 มิลลิกรัมต่อลิตรก์มีบางซ้ำที่วัดแล้ว ค่าต่ำกว่าแบลงค์ทำให้ไม่สามารถคำนวณออกมาเป็นค่าซีโอดีได้

9) จากภาพถ่าย FESEM ของซิงค์ออกไซด์ที่ผ่านการวัดซีโอดี เปรียบเทียบกับก่อนวัดซีโอดี พบว่า ลักษณะสัณฐานวิทยาของซิงค์ออกไซด์มีการเปลี่ยนแปลงและความ หนาลดลงหลังใช้วัดซีโอดี และเมื่อใช้ FESEM โหมด EDS เพื่อดูองค์ประกอบของธาตุที่มีอยู่บนพื้นผิว ของตัวเร่งปฏิกิริยาก็พบว่า มีการลดลงของซิงค์ที่อยู่บนฐานรองรับ นอกจากนั้นยังพบพีคของโซเดียม (Na) ซัลเฟอร์ (S) และโปแทสเซียม (K) ซึ่งเป็นองค์ประกอบของสารละลายโซเดียมซัลเฟส (Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) และ โพแทสเซียมไฮโดรเจนพลาเลต (KHP) ที่ใช้ในการทดลองด้วย เมื่อทำการเก็บตัวอย่างน้ำหลังการวัดซีโอ ดีโดยใช้ซิงค์ออกไซด์ที่ผ่านการสปัตเตอริงไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง ICP-MS พบว่า ซิงค์ออกไซด์ที่ผ่าน การสปัตเตอริงที่เวลา 120 นาที (ขนาด 1.0x1.0 ตารางเซนติเมตร) พบซิงค์และทองแดงในน้ำตัวอย่าง 620 และ 480.9 ไมโครกรัมต่อลิตร ตามลำดับ และ 480 นาที (ขนาด 0.5x0.5 ตารางเซนติเมตร) พบซิงค์และ ทองแดงในน้ำตัวอย่าง 160.6 และ 602.2 ไมโครกรัมต่อลิตร ตามลำดับ ซึ่งการหลุดลอกของซิงค์ออกไซด์ และทองแดงทำให้พื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อการวัดซีโอดี ทำให้ค่าซีโอดีที่ทำการวัด ซ้ำมีค่าไม่เท่ากัน และในบางครั้งมีค่าต่ำกว่า blankซึ่งเมื่อพิจารณาจากข้อมูลการทดสอบที่ได้นี้ทำให้สรุป ได้ว่าไม่ควรนำซิงค์ออกไซด์มาใช้งานซ้ำในการวัดซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส

### 5.2.2 ข้อเสนอแนะ

 ถ้าแสงที่ฉายไปยังตัวเร่งปฏิกิริยามีความไม่เสถียรจะทำให้วัสดุกึ่งตัวนำซิงค์ออก ไซด์ที่นำมาใช้ในกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสทำงานได้ไม่สมบูรณ์และส่งผลต่อกระแสไฟฟ้าที่ ได้จากการวัดซีโอดี ดังนั้น แหล่งกำเนิดแสงจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ควรพิจารณาสำหรับ กระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส

 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ โดยการผสมหรือเจือโลหะชนิดอื่นเพื่อให้ตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ที่จะนำมาใช้วัดซีโอดีใน กระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสมีความเสถียรและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3) ขนาดพื้นที่ผิวตัวเร่งปฏิกิริยาควรมีความสมดุลกับความเข้มข้นและปริมา ตของตัวอย่างน้ำ และควรควบคุมให้พื้นที่ของซิงค์ออกไซด์ให้มีขนาดที่เท่ากันเพื่อให้มีพื้นที่ผิวที่ ใกล้เคียงกันและมีค่าซีโอดีที่ใกล้เคียงกันเมื่อนำไปวัดซีโอดีซ้ำโดยใช้ตัวอย่างคนละแผ่น นอกจากนั้น ควรศึกษาเพิ่มเติมเรื่องขนาดที่แตกต่างกันของตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการนำมาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาใน การวัดค่าซีโอดี เนื่องจากขนาดที่ต่างกันย่อมส่งผลให้มีพื้นที่ผิวที่แตกต่างกันด้วย

 ตำแหน่งของการใช้ปากคืบคืบขั้วไฟฟ้ามีผลต่อค่ากระแสที่ทำการวัด หากการ คืบไม่อยู่ในตำแหน่งเดิมจะทำให้กระแสที่วัดได้มีค่าเปลี่ยนแปลง ฉะนั้นควรมีการตรึงตำแหน่งของ ขั้วไฟฟ้าแต่ละขั้วให้อยู่กับที่

5) เนื่องจากคุณภาพของซิงค์ออกไซด์ลดลงเมื่อมีการใช้ซ้ำ ดังนั้นจึงควรทำการ ทดลองโดยทำการวัดแบลงค์ที่ความต่างศักย์ 0.1 โวลต์ ถึง 1.0 โวลต์ เก็บข้อมูลหลาย ๆ ซ้ำ เพื่อเป็น ฐานข้อมูลของแบลงค์ในการนำไปใช้วัดซีโอดี

> ะ ร่าว<sub>ั</sub>กยาลัยเทคโนโลยีสุรุปไ

#### บรรณานุกรม

- กิตติพงษ์ ลิ้มวิเซียร. (2554). การปลูกผนึกนาโนพอรัสซิงค์ออกไซค์โดยระบบอาร์เอฟแมกนิตรอนสปัต เตอริงแบบควบคุมเวลาก๊าซไวปฏิกิริยาและการประยุกต์ใช้. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 121 น.
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม. (2545). ตำราระบบบำบัดมลพิษน้ำ. กรุงเทพฯ : สมาคมวิศวกรรม สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย.
- ใจเพชร แก้วโภคา. (2557). การปลูกฟิล์มบางซิงค์ออกไซด์ที่เติมสารเจือด้วยกระบวนการผลิตต้นทุนต่ำ สำหรับชั้นป้องกันสะท้อนแสงของเซลล์แสงอาทิตย์. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนา<mark>รี.</mark> 110 น.
- ชวิศร์ กรัณย์เมธากุล. (2549). การปรับแต่งผิวหน้าของไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 120 น.
- ชูศรี วงศ์รัตนะ. (2550). เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนค รินทรวิโรฒ. 382 น.
- ธีรพงศ์ เทินเกษม. (2546). การกำจัดนิกเกิ<mark>ลอ</mark>อกจากน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้ผงไททาเนียมไดออกไซด์ ในกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 145 น.
- นิยม โฮ่งสิทธิ์. (2548). การสังเคราะห์เส้นเข็มขัดนาโนซิงค์ออกไซด์ด้วยวิธีอาร์เอฟสปัตเตอริง. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิ<mark>ทยาศาสตรมหา</mark>บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 117 น.
- พนม กาศรุณ, (2550). การศึกษาสมบัติของฟิล์มบางนิกเกิล ที่เคลือบด้วยวิธีระเหยสาร ด้วยลำ อิเล็กตรอนดีซีสปัต<mark>เตอริงและอาร์เอฟสปัตเตอริง. วิทยาน</mark>ิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลั<mark>ยเกษตรศาสตร์. 87 น.</mark>
- ไพฑูรย์ หมายมั่นสมสุข, (2555). การวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียเบื้องต้น. กรมโรงงานอุตสาหกรรม. สืบค้น เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2557. จาก www2.diw.go.th/research/เอกสารเผยแพร่/A15-CODw.pdf

มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์. (2543). คู่มือวิเคราะห์คุณภาพน้ำ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

รัฐพล ดามัน. (2555). วิเคราะห์และออกแบบชุดโคม LED โดยมีชุดบัคควบคุมแรงดัน. วิทยานิพนธ์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีุราชมงคลล้านนาเขตภาคพายัพ เชียงใหม่. 51 น.

- ศรัญญา ทองอุ่น และ อภิชน วัชเรนทร์วงศ์ (2554). ไทเทเนียมไดออกไซด์รูปท่อกับการบำบัด คาร์บอนมอนอกไซด์ . การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 10: 24R4-04.
- ศรัญญา ทองอุ่น. (2555). การบำบัดคาร์บอนมอนอกไซด์ในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงโดยใช้ ไทเทเนียมไดออกไซด์แบบท่อนาโน. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 135 น.

- ศุภกิตติ์ พรหมวิกร. (2552). การสร้างสวิตซ์ความเร่งโดยวิธีการลิโธกราฟฟีด้วยรังสีเอ็กซ์. วิทยานิพนธ์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 117 น.
- อดุล ดือราแม. (2554). การศึกษาฟิล์มบางอลูมิเนียม-ทองแดงที่เคลือบด้วยกระบวนการอาร์เอฟสปัตเตอริง. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 92 น.
- อติพล สว่างอารมย์. (2557). การศึกษาประสิทธิภาพของท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบ อนุภาคทองคำต่อการเสื่อมสภาพของเมทิลีนบลูโดยกระบวนการโฟโตแคตาไลติก. วิทยานิพนธ์ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 77 น.
- อานันท์ปภา ชื่นทรัพย์. (2555). การบำบัดคาร์บอนมอนอกไซด์ในปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิสโดยใช้ ทังสเตนไตรออกไซด์. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี. 146 น.
- Ahmed, S., Rasul, M. G., Brown, R. and Hashib, M. A. (2011). Influence of parameters on the heterogeneous photocatalytic degradation of pesticides and phenolic contaminants in wastewater: a short review. J Environ Manage, 92(3), 311-330.
- Ai, S., Gao, M., Yang, Y., Li, J. and Jin, L. (2004). Electrocatalytic Sensor for the Determination of Chemical Oxygen Demand Using a Lead Dioxide Modified Electrode. *Electroanalysis*, 16: 404-409
- Albu, S.P., Ghicov, A., Macak, J.M. and Schmuki, P. (2007). 250 μm long anodic TiO<sub>2</sub> nanotubes with hexagonal self-ordering. *Phys. Stat. Sol. (RRL)*, 1: R65-R67.
- Albu, S.P., Ghicov, A., Macak, J.M., Hahn, R. and Schmuki, P. (2007). Self-organized, Free-Standing TiO<sub>2</sub> Nanotube Membrane for Flow-through Photocatalytic Applications. *Nano Letters*, 7: 1286-1289.
- Al-Gaashani, R., Radiman, S. Tabet, N., Daud, A.R., (2011). Effect of microwave power on the morphology and optical property of zinc oxide nano-structures prepared via a microwave-assisted aqueous solution method. Materials Chemistry and Physics 125(3), 846-852.
- Andrew D. Eaton, Mary Ann H. and Franson. (2005). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 21<sup>st</sup> Edition. *American Public Health Association*. Washington DC. Method 5220 Chemical oxygen demand (COD).
- Basu, P. K., Saha, N., Maji, S., Saha, H. and Basu, S. (2008). Nanoporous ZnO thin films deposited by electrochemical anodization: effect of UV light. *Journal of Materials Science: Materials in Electronics*, 19(6), 493-499.
- Berthouex, P. and Brown, L. (2002). **Statistics for Environmental Engineers**. 2<sup>nd</sup> Edition. New York: LEWIS PUBLISHERS.

Bing-Nan, L., Woei–Deng, L. and Jie-Chung, L. (1999). Photocatalytic decolorization of methylene blue in aqueous TiO<sub>2</sub> suspension. *Environmental Engineering Science*, 16(3), 165-175.

- Chai, B., Wang, X., Cheng, S., Zhou, H. and Zhang, F. (2014). One-pot triethanolamineassisted hydrothermal synthesis of Ag/ZnO heterostructure microspheres with enhanced photocatalytic activity. *Ceramics International*, 40(1), 429-435.
- Chen, C., Yu, B., Lui, P., Lui, J., and Wang, L. (2011). Investigation of nano-sized ZnO particles fabricated by various synthesis routes. *Journal of Ceramic Processing Research*, 12: 420-425.
- Chen, J., Zhang, J., Xian, Y., Ying, X., Liu, M. and Jin, L. (2005). Preparation and application of TiO<sub>2</sub> photocatalytic sensor for chemical oxygen demand determination in water research. *Water Research*, 43: 1340-1346.
- Deng, Z., C. Huang, J. Huang, M. Wang, H. He, H. Wang and Y. Cao (2010). Effects of Al content on the properties of ZnO:Al films prepared by Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> and ZnO co-sputtering. *Journal of Materials Science: Materials in Electronics* 21(10): 1030-1035.
- Dhakal, R., et al. (2015). Screen-Printed Flexible Bandstop Filter on Polyethylene Terephthalate Substrate Based on Ag Nanoparticles. Journal of Nanomaterials, 1-8.
- Domini, C. E., Hidalgo, M., Marken, F. and Canals, A. (2006). Comparison of three optimized digestion methods for rapid determination chemical oxygen demand: Closed microwaves, open microwaves and ultrasound irradiation. *Analttica Chimica Acta*, 561: 210-217
- Domini, C. E., Vidal, L. and Canals, A. (2009). Trivalent manganese as an environmentally friendly oxidizing reagent for microwave- and ultrasoundassisted demand chemical oxygen determination. *Ultrasonics Sonochemistry*, 16: 686-691.
- Egerton, T.A., Kosa, S.A.M. and Christensen, P.A. (2006). Photoelectrocatalytic disinfection of E.coli suspensions by iron doped TiO<sub>2</sub>. *Phys. Chem. Chem.* Phys. 8: 398-406.
- Faraj and K. Ibrahim (2011). Optical and Structural Properties of Thermally Evaporated Zinc Oxide Thin Films on Polyethylene Terephthalate Substrates. International Journal of Polymer Science, 1-4.
- Farrukh, M. A., Thong, C.-K., Adnan, R., & Kamarulzaman, M. A. (2012). Preparation and characterization of zinc oxide nanoflakes using anodization method and their photodegradation activity on methylene blue. *Russian Journal of Physical Chemistry A*, 86(13), 2041-2048.
- Fox, M.A., and Duley, M.T. (1993). Heterogeneous photocatalysis. *Chemical Reviews*, 93, 341-357.
- Gratzel, M. (2001). Photoelectrochemical cells. Nature. 414: 338-344.

- Han, D., Y. Wang, S. Zhang, L. Sun, R. Han, S. Matsumoto and Y. Ino (2011). Influence of sputtering power on properties of ZnO thin films fabricated by RF sputtering in room temperature. *Science China Information Sciences* 55(4): 951-955.
- Harizanov, O., Ivnova, T. and Harixanova, A. (2001). Study of sol –gel TiO2 and TiO2 MnO obtained from a poetized solution. *Material Letter*, 49, 165-171.
- He, S., Zheng, M., Yao, L., Yuan, X., Li, M., Ma, L. and Shen, W. (2010). Preparation and properties of ZnO nanostructures by electrochemical anodization method. *Applied Surface Science*, 256(8), 2557-2562.
- Herrmann, J. M. (1999). Heterogeneous photocatalysis: fundamentals and applications to the removal of various types of aqueous pollutants. *Catalysis Today*. 53: 115-129.
- Herrmann, J.M. (2010). Fundamentals and misconceptions in photocatalysis. *Journal* of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 216(2-3), 85-93
- Hwang, S., Lee, M. C. and Choi, W. (2003). Highly enhanced photocatalytic oxidation of CO on titania deposited with Pt nanoparticles: kinetics and mechanism. *Applied Catalysis*. 46: 49-63.
- Hoffmann, M. R., Martin, S.T., Choi, W. and Behnemann, D. W. (1995). Environmental applications of semiconductor photocatalysis. *Chemical Reviews*. 95(1): 69-96.
- Jayaraman, V. K., Y. M. Kuwabara, A. M. Álvarez and M. d. l. l. O. Amador (2016). Importance of substrate rotation speed on the growth of homogeneous ZnO thin films by reactive sputtering. *Materials Letters* 169: 1-4.
- Khataee, A. R. and Zarei, M. (2011). Photocatalysis of a dye solution using immobilized ZnO nanoparticles combined with photoelectrochemical process. Desalination, 273(2-3), 453-460.
- Khazamipour, N., S. Kabiri-Ameri-Aboutorabi and E. Ast-Solaimani (2013). The structural, electrical and optical properties of ZnO/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> multilayer deposited on PET substrates by RF sputtering. *Renewable Energy* 49: 275-277.
- Kim, Y.C., Sasaki, S., Yano, K., Ikebukuro, K., Hashimoto, K. and Karube, I. (2000). Photocatalytic sensor for the determination of chemical oxygen demand using flow injection analysis. *Analttica Chimica Acta*, 432: 59-60.
- Li, L., Zhang, S., Li, G. and Zhao, H. (2012). Determination of chemical oxygen demand of nitrogenous organic compounds in wastewater using synergetic photoelectrocatalytic oxidation effect at TiO<sub>2</sub> nanostructured electrode. *Anal Chim Acta*, 754, 47-53.

- Lupan, O., Chow, L., Chai, G., and Heinrich, H. (2008). Fabrication and characterization of Zn–ZnO core–shell microspheres from nanorods. *Chemical Physics Letters*, 465(4-6): 249-253
- Ma, C., Tan, F., Zhao, H., Chen, S. and Quan, X. (2010). Sensitive amperometric determination of chemical oxygen demand using Ti/Sb-SnO<sub>2</sub>/PbO<sub>2</sub> composite electrode. *Sensors and Actuators B*, 155: 114-119.
- Mor, G. K., Varghese, O. K., Paulose, M., Shankar, K. and Grimes, C. A. (2006). A review on highly ordered, vertically oriented TiO2 nanotube arrays: Fabrication, material properties, and solar energy applications. *Solar Energy Materials and Solar Cells*, 90: 2011-2075.
- Mu, Q., Li, Y., Zhang, Q. and Wang, H. (2011). TiO<sub>2</sub> nanofibers fixed in a microfluidic device for rapid determination of chemical oxygen demand via photoelectrocatalysis. *Sensors and Actuators B: Chemical*, 155(2), 804-809.
- Nandi, R. and S. S. Major (2017). The mechanism of growth of ZnO nanorods by reactive sputtering. *Applied Surface Science* 399: 305-312.
- Paulosea, M., Pengc, L., Popatb, K.C., Varghesed, O.K., LaTempaa, T.J., Baoa, N, Desaic, T.A. and Craig A. Grimes, C.A. (2008). Fabrication of mechanically robust, large area, polycrystalline nanotubular/porous TiO<sub>2</sub> membranes. *Journal of Membrane Science*, 319: 199-205.
- Prepelita, P., V. Craciun, M. Filipescu and F. Garoi (2013). Sputtered zinc oxide thin films deposited on polyimide substrate and annealing effect on the physical characteristics. *Thin Solid Films* 545: 564-570.
- Purohit, A., S. Chander, A. Sharma, S. P. Nehra and M. S. Dhaka (2015). Impact of low temperature annealing on structural, optical, electrical and morphological properties of ZnO thin films grown by RF sputtering for photovoltaic applications. *Optical Materials* 49: 51-58.
- Silvestre, C. I.C., Frigerio, C., Santos, J. L.M. and Lima, J. L.F.C. (2011). Quantum dots assisted photocatalysis for the chemiluminometric determination of chemical oxygen demand using a single interface flow system. *Analttica Chimica Acta*, 699: 193-197.
- Sreedhar, A., J. H. Kwon, J. Yi, J. S. Kim and J. S. Gwag (2016). Enhanced photoluminescence properties of Cu-doped ZnO thin films deposited by simultaneous RF and DC magnetron sputtering. *Materials Science in Semiconductor Processing* 49: 8-14.
- Stafford, U., Gray, K.A. and Kamat, P.V. (1996). Photocatalytic degradation of organic contaminants: halophenols and related model compounds, Heterogen. *Chemical Reviews*, 3, 77–104.

- Tang, W.Z., Zhang, Z., An, H., Quintana, M.O. and Torres, D.F. (1997). Photodegradation of azo dyes in aqueousnnsolution. *Environmental Technology*, 18, 112.
- Venkatadri, R. and Peters, R.W. (1993). Chemical oxidation technologies: ultraviolet light/hydrogen peroxide, fenton's reagent, and titanium dioxide-assisted photocatalysis. *Hazardous Waste Hazard Mater.* 2, 107–149.
- Wang, C., Wu, J., Wang, P., Ao, Y., Hou, J. and Qian, J. (2013). Photoelectrocatalytic determination of chemical oxygen demand under visible light using Cu<sub>2</sub>O-loaded TiO<sub>2</sub> nanotube arrays electrode. *Sensors and Actuators B: Chemical*, 181, 1-8.
- Wanga, C., Xu, B.Q., Wang, X. and Zhao, J. (2005). **Preparation and photocatalytic** activity of ZnO/TiO<sub>2</sub>/SnO<sub>2</sub> mixture. *Journal of Solid State Chemistry*, 178, 3500 -3506.
- Wernick, S., Pinner, R. and Sheasby, P.G. (1987). The Surface Treatment and Finishing of Aluminum and its Alloy. Finshing Publications, Middlesex, England.
- Yang, J., Chen, J., Zhou, Y. and Wu, K. (2010). A nano-copper electrochemical sensor for sensitive detection of chemical oxygen demand. Sensors and Actuators B, 153: 78-82.
- Zhang, A., Zhou, M. and Zhou, Q. (2010). A combined photocatalytic determination system for chemical oxygen demand with a highly oxidative reagent. *Analttica Chimica Acta*, 686: 133-143.
- Zhang, J., Zhou, B., Zheng, Q., Li, J., Bai, J., Liu, Y. and Cai, W. (2009). Photoelectrocatalytic COD determination method using highly ordered TiO<sub>2</sub> nanotube array. *Water Research*, 43: 1986-1992.
- Zhang, S., Li, L., Zhao, H. and Li, G. (2009). A portable miniature UV-LED-based photoelectrochemical system for determination of chemical oxygen demand in wastewater. *Sensors and Actuators B*, 141: 634-640.
- Zhang, Z., X. Chang and A. Chen (2016). Determination of chemical oxygen demand based on photoelectrocatalysis of nanoporous TiO<sub>2</sub> electrodes. *Sensors and Actuators B: Chemical* 223(Supplement C): 664-670.
- Zhang, Z., Liu, H., Zhang, H., Dong, H., Liu, X., Jia, H. and Xu, B. (2014). Synthesis of spindle-like Ag/ZnO heterostructure composites with enhanced photocatalytic performance. *Superlattices and Microstructures*, 65, 134-145.
- Zhang, Z., Yuan, Y., Fang, Y., Liang, L., Ding, H. and Jin, L. (2007). Preparation of photocatalytic nano-ZnO/TiO<sub>2</sub> film and application for determination of chemical oxygen demand. *Talanta*, 73: 523-528.

- Zhao, H., Jiang. D., Zhang, S., Catterall, K. and John, R. (2004). Development of a Direct Photoelectrochemical Method for Determination of Chemical Oxygen Demand. *Anal. Chem.*, 76:155-160.
- Zhao, J. and Yang, X. (2003). Photocatalytic oxidation for indoor air puri&cation: a literature review. *Building and Environment*. 38: 645 654.
- Zhao, J., Wang, X., Liu, J., Meng, Y., Xu, X. and Tang, C. (2011). Controllable growth of zinc oxide nanosheets and sunflower structures by anodization method. *Materials Chemistry and Physics*, 126(3), 555-559.



ภาคผนวก ก

รายละเอียดเ<mark>ครื่องมือวิเคราะห์คุณสมบัติของตัว</mark>เร่งปฏิกิริยา



#### ก. รายละเอียดเครื่องมือวิเคราะห์คุณลักษณะของซิงค์ออกไซด์

ในการศึกษานี้ได้ทำการศึกษาคุณลักษณะและคุณสมบัติของซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ขึ้นเพื่อ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส โดยมีรายละเอียดเครื่องมือวิเคราะห์ ดังนี้

#### ก.1 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดความละเอียดสูง

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดความละเอียดสูง (Field emission scanning electron microscope, FESEM) เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการตรวจวิเคราะห์ลักษณะ พื้นผิว ขนาด รูปร่างของอนุภาค และลักษณะการกระจายของเฟสในโครงสร้างจุลภาคของวัตถุ มี ้กำลังขยายสูงถึง 1,000,000 เท่า ทำให้สามารถศึกษาโครงสร้างขนาดเล็กระดับนาโนได้อย่างมี ้ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์<mark>วิเ</mark>คราะห์ธาตุเชิงพลังงาน (Energy Dispersive X-Ray Spectrometer : EDS) ซึ่งช่วยในการศึกษาอ<mark>งค์ป</mark>ระกอบของธาตุทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และการ ้กระจายขององค์ประกอบธาตุ ในงานวิจัยได้ใช้ FESEM ยี่ห้อ JEOL รุ่น JSM-7001F ที่ศูนย์วิจัยทาง ้ ฟิสิกส์ของฟิล์มบาง ภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาล<mark>ง</mark>กรณ์ม<mark>ห</mark>าวิทยาลัย ยี่ห้อ JEOL รุ่น JSM 7800F และยี่ห้อ Zeiss รุ่น AURIGA ที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศ<mark>า</mark>สตร์แล<mark>ะเ</mark>ทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยที่ทั้ง 3 เครื่อง ดังรูปที่ ก.1 มีแหล่งกำเนิ<mark>ดอิเ</mark>ล็กตรอน<mark>แบ</mark>บ Schottky type field-emission 1) FESEM ี้ยี่ห้อ JEOL รุ่น JSM 7800F มี resolution สูงถึง 1.2 nm ที่ 30 kV ศักย์เร่งอิเล็กตรอนปรับเปลี่ยนได้ ในช่วง 0.5-30 kV 2) ยี่ห้อ JEOL <mark>รุ่น J</mark>SM 7<mark>800F</mark> มี reso<mark>luti</mark>on สูงถึง 0.8 nm ที่ 15 kV และ 1.2 ที่ 1 kV ศักย์เร่งอิเล็กตรอนปรับเปลี่ยนได้ในช่วง 0.1-30 kV 3) FESEM ยี่ห้อ Zeiss รุ่น AURIGA มี resolution สูงถึง 1.0 nm ที่ 15 kV และ 1.9 ที่ 1 kV ศักย์เร่งอิเล็กตรอนปรับเปลี่ยนได้ในช่วง 0.1-30 kV ส่งสัญญาณภาพจาก secondary electrons (SEs) ที่หลุดออกมาจากพื้นผิวของชิ้นงานเมื่อถูกลำ อิเล็กตรอนชนมาประมว<mark>ลผล ภาพที่ได้แสดงให้เห็นลักษณะ</mark>ขอ<mark>งพื้นผ</mark>ิวของบนชิ้นงาน (Morphology) และสัญญาณภาพจาก Backscattered Electron (BSEs) ที่สะท้อนจากพื้นผิวของชิ้นงานมาประมวลผล ้สัญญาณที่ได้ในแต่ละบริเวณ<mark>จะแปรตามเลขอะตอม (atomic nu</mark>mber) ในเนื้อสารบริเวณนั้น ๆ ภาพที่ ้ได้ จึงมีความสว่าง เข้มหรืออ่อน<mark>ตามเลขอะตอมของธาตุ</mark>ที่เป็นส่วนประกอบของเนื้อสาร (atomic contrast) BEI จึงสามารถแสดงภาพที่แยกแยะความแตกต่างของแต่ละบริเวณที่มีธาตุหรือสารประกอบ ยาลยเทคโนโลข ต่างชนิดกันได้



รูปที่ ก.1 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดความละเอียดสูง ก) ยี่ห้อ JEOL รุ่น JSM-7001F ข) ยี่ห้อ JEOL รุ่น JSM 7800F และ ค) ยี่ห้อ Zeiss รุ่น AURIGA

#### 184

#### ก.2 กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม

กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม (Atomic force microscope, AFM) เป็นเครื่องมือที่ใช้ ในการตรวจวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิว ความขรุขระ และการกระจายตัวของสารเคลือบบนผิวฟิล์มบาง หลักการสำคัญของกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม คือ จะนำผลของแรงระหว่างอะตอมหรือที่เรียกว่า แรงแวนเดอร์วาลส์ (van der Waals force) ระหว่างปลายของโพรบ (probe) หรือเข็ม (tip) ขนาด 2-10 นาโนเมตร และพื้นผิวของตัวอย่างไปประมวลผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ผลออกมาเป็นรูปภาพ พื้นผิวทั้งในแบบ 2 มิติหรือ 3 มิติ ซึ่งแรงแวนเดอร์วาลส์นี้จะเป็นได้ทั้งแรงดูดและแรงผลักโดยจะขึ้นอยู่กับ ระยะห่างระหว่างปลายเข็มและพื้นผิวของชิ้นงาน (พิฆเนศ อุปชัย, 2557) ในงานวิจัยใช้ กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม ยี่ห้อ Park Systems รุ่น XE-120 ดังรูปที่ ก.2 สามารถสแกนภาพขนาดใหญ่ ที่สุดไม่เกิน 100x100 ไมโครเมตร พื้นผิวตัวอย่างควรมีระดับความสูงต่ำไม่เกิน 25 ไมโครเมตร โดยการ สแกนในแนวนอนมีกำลังแยกแยะ (spatial resolution) 0.05 นาโนเมตร การสแกนในแนวดิ่งมีกำลัง แยกแยะ 0.1 นาโนเมตร



รูปที่ ก.2 กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

# ก.3 เครื่องวัดความหนาฟิล์มด้วยแสง

ในงานวิจัยใช้เครื่องวัดความหนาฟิล์มด้วยแสง (Optical profiler) ของบริษัท Veeco รุ่น WYKO NT9100 ดังรูปที่ ก.3 ที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สามารถวัด ความหนาของชิ้นงานตั้งแต่ 0.1 นาโนเมตรถึง 1 มิลลิเมตร และความหยาบของพื้นผิวตั้งแต่ระดับ อังสตรอมถึงนาโนเมตร ความเร็วในการแสกนสูงสุด 7.2 ไมโครเมตรต่อวินาที มีกำลังขยายตั้งแต่ 1.5-50 เท่า สามารถวัดค่าพื้นผิววัตถุในรูปแบบ 3 มิติ ความกว้าง ความยาว ความลึก (ในแนวแกน X, Y, Z) และวัดค่าความหนาออกมาเป็นตัวเลขได้ มีหลักการทำงาน คือ ใช้ความแตกต่างกันของคลื่นสเปกตรัม โดยเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับของแสงในระดับความสูงที่แตกต่างกันของพื้นผิวที่ต้องการ ทราบความหนากับพื้นผิวขิงวัสดุอ้างอิง



รูปที่ ก.3 เครื่องวัดความหนาฟิล์มด้วยแสง ที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

# ก.4 เครื่องเอ็กซเรย์ดิฟแฟรคโทมิเตอร์

เครื่องเอ็กซเรย์ดิฟแฟรคโทมิเตอร์ (X-ray diffractometer, XRD) อาศัยการเลี้ยวเบน ของรังสีเอ็กซ์ เมื่อรังสีตกกระทบวัตถุ (Incident X-ray) หรืออนุภาคจะเกิดการหักเหของลำรังสีสะท้อน ออกมาทำมุมกับระนาบของอนุภาคทำให้เกิดการเลี้ยวเบนของรังสีที่มุมต่าง ๆ กัน โดยมีตัวรับสัญญาณ (Detector) เป็นตัวรับข้อมูล มุมในการหักเหของรังสีจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบและโครงสร้างของ อนุภาคที่อยู่บนชิ้นงาน ข้อมูลที่ได้รับสามารถบ่งบอกชนิดของสารประกอบที่มีอยู่ในสารตัวอย่างและ สามารถนำมาใช้ใช้ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างของผลึกของสารตัวอย่างนั้น ๆได้ ในงานวิจัยใช้ เครื่อง XRD ยี่ห้อ BRUKER รุ่น D8 ADVANCE ดังรูปที่ ก.4 โดยทำการสแกนที่มุม 2theta ตั้งแต่ 20° ถึง 80° ความเร็วในการแสกน 0.5 sec/ step ข้อมูลที่ได้นำมาเทียบกับฐานข้อมูลที่ต้องการทราบ เช่น ซิงค์ออกไซด์ ตามข้อมูล JCPDS card (No. 36-1451, a = 0.3249 nm, c = 0.5206 nm) จะปรากฏ ที่พีค 2 $\mathbf{0}$  = 31.7° 34.4° 36.3° 47.5° 56.6° 62.3° 66.5° 67.9° และ 69.1°สอดคล้องกับระนาบผลึก (100) (002) (101) (102) (110) (103) (200) (112) และ (201) ตามลำดับ เป็นต้น



รูปที่ ก.4 การหักเหของรังสี X-Ray (ใจเพชร แก้วโภคา, 2557) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

## ก.5 เครื่องวิเคราะห์ผิววัสดุ

เครื่องวิเคราะห์ผิววัสดุ (X-ray Photoelectron Spectroscopy, XPS) มีหลักการคือ ใช้พลังงานโฟตอนจากรังสีเอ็กซ์เพื่อกระตุ้นให้เกิดโฟโต้อิเล็กตรอนแล้วทำการวิเคราะห์ ค่าพลังงานยึดเหนี่ยว (Binding energy, BE) ของอิเล็กตรอนชั้นในสุด (core electron) เนื่องจาก ค่าพลังงานดังกล่าวเป็นลักษณะเฉพาะของอะตอมในแต่ละธาตุและขึ้นอยู่กับสถานะทางเคมี (Chemical state) ของอะตอมนั้น การวิเคราะห์ดังกล่าวจึงสามารถระบุชนิดและสถานะทางเคมีของธาตุที่เป็น องค์ประกอบบริเวณพื้นผิวของสารที่ต้องการวิเคราะห์ได้ ซึ่งสภาวะทางเคมี (Chemical Environment) และเลขออกซิเดชันของอะตอมที่ปลดปล่อยโฟโต้อิเล็กตรอนออกมามีผลต่อรูปร่างของพีคและค่าพลังงาน ยึดเหนี่ยว ในขณะที่ความสูงของพีคมีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณของธาตุที่อยู่ในสารตัวอย่าง เทคนิค นี้จึงวิเคราะห์ได้ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงประมาณ งานวิจัยใช้เครื่อง XPS ที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ในการวิเคราะห์ชนิดและสถานะทางเคมีของธาตุที่เป็นองค์ประกอบที่เกิดบนพื้นผิวของ ตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ที่สปัตเตอริงบน PET ในงานวิจัยใช้เครื่องมือที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)



รูปที่ ก.5 ส่วนประกอบหลักของเครื่อง X-ray Photoelectron Spectroscopy (อติพล สว่างอารมย์, 2557)

## ก.6 เครื่องมือวิเคราะห์การตอบสนองของปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีแสง

การวิเคราะห์การตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีแสง เพื่ออธิบายความสามารถของ ตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ในการตอบสนองต่อแหล่งกำเนิดแสง โดยใช้วิธีการวัดอิเล็กตรอนที่เกิดขึ้น ในรูปของความหนาแน่นของกระแส (Photocurrent density) หลังจากการกระตุ้นด้วย การฉายแสงผ่านตัวเร่งปฏิกิริยา โดยอาศัยหลักการของเซลล์เคมีไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้วไฟฟ้า โดย ใช้แผ่นซิงค์ออกไซด์ ขนาด 4 ตารางเซนติเมตร พื้นที่ทำปฏิกิริยา 1 ตารางเซนติเมตร ต่อเป็นขั้วไฟฟ้าใช้ งาน แพลทินัมต่อเป็นขั้วไฟฟ้าร่วม และซิลเวอร์/ซิลเวอร์คลอไรด์ (Ag/AgCl) เป็นขั้วไฟฟ้าอ้างอิง จุ่ม ขั้วไฟฟ้าทั้ง 3 ลงในสารละลายนำไฟฟ้าโซเดียมซัลเฟต (Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) ความเข้มข้น 0.5 โมลาร์ สารละลายที่ ใช้ จะ ถูกนำไปเป่าไล่ อ ก ซิเจน (Deoxygenated) โดยใช้ ก๊าซไนโตรเจนเป็นเวลา อย่างน้อย 20 นาที และต่อเซลล์ไฟฟ้าเคมีเข้ากับเครื่องโพเทนซิโอสแตท (Potentiostat, Mettrohm Autolab) ที่ต่อกับคอมพิวเตอร์ กำหนดค่าความต่างศักย์ ที่ 5 มิลลิโวลต์ต่อวินาที โดยกำหนดค่า Start potential Stop potential Step potential และ Scan rate เท่ากับ -0.1 โวลต์ 2.0 โวลต์ 0.001 โวลต์ และ 0.005 โวลต์ต่อวินาที ตามลำดับ โดยแหล่งกำเนิดแสงที่ใช้อยู่ในช่วงแสงขาว (PHILIPS Essential Halogen 12 โวลต์ 50 วัตต์) ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์แบบท่อนา โนประมาณ 2 เซนติเมตร โดยมีการควบคุมให้ไม่มีผลกระทบจากแสงภายนอก ดังแสดงเครื่องมือตาม รูปที่ ก.6



รูปที่ ก.6 การวิเคราะห์การตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีแสงด้วยเครื่องโพเทนซิโอสแตท ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

### ก.7 เครื่องตรวจวัดสารด้วยการดูดกลืนแสง

เครื่องตรวจวัดสารด้วยการดูดกลืนแสง (UV-VIS Spectrophotometer) เป็นเครื่องมือที่ใช้ใน การตรวจวัดปริมาณแสงและค่า intensity ในช่วงรังสียูวีและช่วงแสงขาวที่ทะลุผ่านหรือถูกดูดกลืนโดย ตัวอย่างที่วางอยู่ในเครื่องมือ โดยที่ความยาวคลื่นแสงจะมีความสัมพันธ์กับปริมาณและชนิดของสารที่ อยู่ในตัวอย่าง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสารอินทรีย์ (Organic Compound) สารประกอบเชิงซ้อน (Complex Compound) หรือสารอนินทรีย์ (Inorganic Compound) ที่สามารถดูดกลืนแสงในช่วง ความยาวคลื่นเหล่านี้ได้ คุณสมบัติในการดูดกลืนแสงของสารเมื่อโมเลกุลของตัวอย่างถูกฉายด้วยแสง ในช่วงรังสียูวีหรือแสงขาวที่มีพลังงานเหมาะสมจะทำให้อิเล็กตรอนภายในอะตอมเกิดการดูดกลืนแสง แล้วเปลี่ยนสถานะไปอยู่ในขั้นที่มีระดับพลังงานสูงกว่า เมื่อทำการวัดปริมาณของแสงที่ผ่านหรือสะท้อน มาจากตัวอย่างเทียบกับแสงจากแหล่งกำเนิดที่ความยาวคลื่นค่าต่าง ๆ ตามกฎของ Beer-Lambert ค่า การดูดกลืนแสง (absorbance) ของสารจะแปรผันกับจำนวนโมเลกุลที่มีการดูดกลืนแสง ดังนั้นจึง สามารถใช้เทคนิคนี้ในระบุชนิดและปริมาณของสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตัวอย่างได้ (คู่มือวิเคราะห์เครื่องมือ ชั้นสูง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2555) ในงานวิจัยใช้ เครื่องตรวจวัดสาร ด้วยการดูดกลืนแสง ยี่ห้อ Agilent Tecnologies รุ่น Cary 300 ทำการวัดการสะท้อนของแสงของ ตัวอย่างชิงค์ออกไซด์ที่ความยาวคลื่น 190-600 นาโนเมตร แล้วแปลงเป็นค่าการดูดกลืนแสง เครื่องมือ แสดงดังรูปที่ ก.7



รูปที่ ก.7 เครื่องตรวจวัดสารด้วยการดูดกลืนแสง ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

## ก.8 เครื่องมือวิเคราะห์ธาตุ (ICP-MS)

เครื่องมือวิเคราะห์ธาตุ (Inductively Couple Plasma Mass Spectrometer, ICP-MS) ใช้เป็นเครื่องมือหาปริมาณธาตุในตัวอย่างชนิดต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์ชนิดของธาตุได้ถึง 81 ชนิด ในการวัดตัวอย่างหนึ่งครั้ง โดยปริมาณของธาตุในตัวอย่าง ควรอยู่ในช่วงความเข้มข้น ระดับส่วนใน พันล้านส่วน (ppb) และมีปริมาณของแข็งที่ละลายอยู่ไม่เกิน 0.2 % เครื่อง ICP-MS จะประกอบด้วย ระบบหลัก ๆ 2 ระบบ คือ ส่วนของ ICP (Inductively Coupled Plasma) ที่ธาตุในตัวอย่างจะถูกไอ ออในซ์เป็นไอออน แล้วผ่านไปสู่ระบบของ Quadrupole Mass Spectrometer ในการแยกชนิดของ ธาตุ ๆ ตาม อัตราส่วนของมวลต่อประจุ (Atomic Mass-to-Charge Ratio) ก่อนตรวจวัดปริมาณด้วย Electron Multiplier Detector (คู่มือวิเคราะห์เครื่องมือชั้นสูง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี, 2555 ) งานวิจัยใช้เครื่อง ICP-MS รุ่น Agilent 7500 series ดังรูปที่ ก.8 เพื่อหา ปริมาณซิงค์ ซึ่งเป็นธาตุองค์ประกอบของซิงค์ออกไซด์ และทองแดงซึ่งเป็นฐานรองรับของซิงค์ออกไซด์ เพื่อ ตรวจสอบดูว่า วัสดุที่นำมาใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการวัดค่าซีโอดีนั้นมีความเสถียรหรือไม่



รูปที่ ก.8 Inductively Couple Plasma Mass Spectrometer

ภาคผนวก ข

ผ<mark>ลการทดลองเบื้องต้</mark>น

ะ ราวารายาลัยเทคโนโลยีสุรบาร

### ข.1 ผลการทดลองการวิเคราะห์หาค่าซีโอดีด้วยวิธีมาตรฐานไดโครเมต แบบ Closed Reflux

ในการเตรียมน้ำเสียสังเคราะห์จะต้องทำการหาค่าซีโอดีในน้ำตัวอย่างเพื่อนำไปใช้เปรียบเทียบ กับค่าซีโอดีที่ได้จากกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส (COD<sub>PEC</sub>) โดยในที่นี้จะใช้วิธีมาตรฐานไดโคร เมต (COD<sub>cr</sub>) แบบ Closed Reflux ในการหาค่าซีโอดี และจากการหาค่าซีโอดีของสารละลายมาตรฐาน ดีกลูโคสซึ่งเป็นตัวแทนของค่าซีโอดีในน้ำ แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ส่วน คือ สารละลายมาตรฐานดี กลูโคส และสารละลายมาตรฐานดีกลูโคสที่เติมโซเดียมซัลเฟตเป็นสารอิเล็กโทรไลต์ แสดงดัง ตารางที่ ข.1 ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่าซีโอดีที่ได้จากวิธีมาตรฐานไดโครเมตมีค่าใกล้เคียงกับค่าซีโอดีจากการ คำนวณทางทฤษฎี

คำนวณทาง	วิ <mark>ธีม</mark> าตรฐานไดโครเมต				
ทฤษฎี	ลืออโดส		ดีกลูโคส + โซเดียมซัลเฟต 0.01		
(มิลลิกรัมต่อ	ທາເຄູເຕດ (ນີ້ລຸລີດຮັບຕໍ່ລຸລີຕະ)	S. <mark>D.</mark>	S. <mark>D.</mark> โมลาร์		
ລືຫร)	(អឧតបារអស់ត្ថមសារ)		(มิลลิกรัมต่อลิตร)		
10	12.76	1. <mark>9</mark> 94	16.82	4.494	
25	28.35	<mark>0.</mark> 906	30.40	1.837	
50	60.35	1.109	59.57	1.125	
100	103.03	3.954	95.32	3.843	
125	130.21	2.868	123.90	5.403	
250	239.32	0.907	247.80	1.853	
500	485.14	7.369	477.38	2.930	

ตารางที่ ข.1 แสดงค่าซีโอดีที่วิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐานไดโครเมต (COD<sub>cr</sub>) แบบ Closed Reflux (n=5)



### ข.2 ผลการทดลองการวัดค่าความส่องสว่างของแสงด้วยลักซ์มิเตอร์ (lux meter)

แสงเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส เนื่องจากวัสดุกึ่ง ้ตัวน้ำจะต้องได้รับพลังงานจากแสงมากกว่าหรือเท่ากับแถบช่องว่างพลังงาน (band gap) อิเล็กตรอน ้ในชั้นแถบเวเลนซ์ จึงจะถูกกระตุ้นให้มีพลังงานเพิ่มขึ้นจนเคลื่อนที่เข้าสู่ชั้นแถบการนำไฟฟ้า ทำให้เกิดที่ ้ ว่างของอิเล็กตรอน (hole, h<sup>+</sup>) ในชั้นแถบเวเลนซ์ กลายเป็นคู่ของอิเล็กตรอนและที่ว่างของอิเล็กตรอน (e<sup>-</sup>/h<sup>+</sup>) ที่วิ่งกระจายตัวอยู่ที่ผิวของวัสดุกึ่งตัวนำ ที่ว่างของอิเล็กตรอนหรือโฮลในชั้นแถบเวเลนซ์จะเป็น ้ตัวออกซิไดส์หรือตัวรับอิเล็กตรอนที่ดี (Strong Oxidant) และอิเล็กตรอนในแถบคอนดักชันจะเป็นตัว รีดิวซ์หรือตัวให้อิเล็กตรอนที่ดี (Hoffman, Martin, Choi and Behnemann, 1995, Ahmed, Rasul, Brown, and Hashib, 2011 และอานันท์ปภา ชื่นทรัพย์, 2555) ดังนั้น ถ้าแสงที่ฉายไปยังตัวเร่ง ้ปฏิกิริยามีความไม่เสถียรจะทำให้วัสดุกึ่งตัวนำซิงค์ออกไซด์ที่นำมาใช้ในกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะ ตะไลซิสทำงานได้ไม่สมบูรณ์และส่งผลต่อกระแสไฟฟ้าที่ได้จากการวัดซีโอดี จึงทำการปรับปรุง แหล่งกำเนิดแสง โดยติดพัดลมระบายอากาศ ดังร<mark>ูปที่</mark> ข.2 เพื่อลดอุณหภูมิและป้องกันไม่ให้ความเข้ม ้แสงของหลอดไฟลดลง (รัฐพล ดามัน, 2555) จา<mark>กนั้นจึง</mark>ทำการทดสอบโดยการวัดค่าความส่องสว่างของ ์ แสงก่อนและหลังปรับปรุงแหล่งกำเนิดแสง ด้ว<mark>ย</mark>ลักซ์ม**ิเ**ตอร์ (lux meter) ยี่ห้อ Konica Minolta รุ่น T10A เพื่อเป็นตัวแทนในการศึกษาความเสถีย<mark>ร</mark>ของแสง<mark>ท</mark>ี่ใช้ โดยทำการวัดค่าความส่องสว่างของแสง ้ก่อนปรับปรุงต่อเนื่องเป็นเวลา 60 นาที จะเ<mark>ห็น</mark>ได้ว่าควา<mark>มส่</mark>องสว่างลดลงเรื่อย ๆ เมื่อระยะเวลาผ่านไป ข้อมูลดังตารางที่ ข.2.1



รูปที่ ข.2 ติดพัดลมระบายอากาศเพื่อลดอุณหภูมิเครื่องแหล่งกำเนิดแสง ก) ก่อนปรับปรุง ข) หลังปรับปรุง

ระยะเวลาที่เปิดไฟ	ความเข้มแสง (ลักซ์)			
(นาที)	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	
1	158.6	159.5	162.4	
5	106.4	107.4	110.0	
10	87.7	89.6	90.9	
15	81.5	84.6	84.8	
30	80.0	81.3	80.1	
60	78.6	81.8	77.5	

ตารางที่ ข.2.1 ความส่องสว่างของแสงก่อนติดพัดลมระบายอากาศ

จากนั้นทำการศึกษาเปรียบเทียบความส่อ<mark>งส</mark>ว่างของแสงก่อนและหลังปรับปรุงโดยทำการเก็บ ข้อมูลเมื่อเปิดใช้งานเป็นเวลา 1 นาที และ 5 นาที ทุก ๆ รอบของการวัดจะรอกระทั่งหลอดไฟเย็นลง และค่าความส่องสว่างเริ่มต้นมีค่าใกล้เคียงกัน ข้<mark>อ</mark>มูลดังต</mark>ารางที่ ข.2.2

ตารางที่ ข.2.2 ค่าความส่องสว่างของแสงก่อ<mark>นแ</mark>ละหลังติ<mark>ดพัด</mark>ลมระบายอากาศ

		ก่อน			หลัง	
ความส่องสว่าง (ลักซ์)	เริ่มต้น	1 นาที	5 <mark>นาท</mark> ี	เริ่มต้น	1 นาที	5 นาที
	20 <mark>2</mark> .04	159.02	106. <mark>6</mark> 4	93.50	91.86	89.06
S.D. (n=5)	0.61	1.54	1.63	0.75	0.36	0.68
การลดลง (%)		21.29	47.22		1.75	4.74



### ข.3 ผลการศึกษาการตอบสนองของซิงค์ออกไซด์ที่ความต่างศักย์ต่าง ๆ

การวัดซ้ำจากการศึกษาผลของการจ่ายความต่างศักย์ไฟฟ้าของน้ำตัวอย่างที่มีเพียงสารละลายอิ เล็กโทรไลต์โซเดียมซัลเฟต 0.1 โมลาร์ (Q<sub>(b)</sub>) กับสารละลายอิเล็กโทรไลต์โซเดียมซัลเฟต 0.1 โมลาร์ที่มี สารอินทรีย์ที่ให้ค่าซีโอดีในเชิงทฤษฎี คือ โพแทสเซียมไฮโดรเจนพลาเลต (Potassium hydrogen phthalate, KHP) ที่มีความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อลิตร (Q<sub>(total</sub>)) โดยใช้แผ่นซิงค์ออกไซด์เดียวกันวัด สลับกันระหว่าง Q<sub>(blank)</sub> และ Q<sub>(total</sub>) ที่ความต่างศักย์ตั้งแต่ 0.1 โวลต์ จนถึง 1.0 โวลต์ เพื่อตรวจสอบดู ว่าที่การจ่ายความต่างศักย์ใดเหมาะสมสำหรับการวัดซีโอดี ข้อมูลแสดงดังตารางที่ ข.3 และเมื่อนำมา พล็อตแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต่างศักย์กับ Q ในแต่ละซ้ำจะได้กราฟดังรูปที่ ข.3.1-ข.3.3

ความต่างศักย์	ครั้ง	ที่ 1	ครั้งที่ 2		ครั้งที่ 3	
(โวลต์)	Q <sub>b</sub>	Q <sub>total</sub>	Q <sub>b</sub>	Q <sub>total</sub>	Q <sub>b</sub>	Q <sub>total</sub>
0.1	4.53341	9.80895	4.70922	9.37398	4.40678	10.45215
0.2	18.24098	20.25814	16.57 <mark>6</mark> 39	19.37094	22.55435	26.06447
0.3	35.09862	33.87175	32.679 <mark>6</mark> 1	34.96138	38.71873	39.17332
0.4	39.72926	44.4115 <mark>3</mark>	39.7780 <mark>3</mark>	49.88387	47.46717	44.57147
0.5	30.44202	47.5 <mark>847</mark> 3	48.4887	<mark>52</mark> .25405	51.61956	50.59977
0.6	40.87928	64 <mark>.232</mark> 21	65.21867	71.72779	59.42707	70.53605
0.7	59.58360	7 <mark>2</mark> .11777	73.64127	79.04827	81.02114	81.11437
0.8	57.25652	72.52023	87.53233	83.44413	89.15465	101.5189
0.9	72.20565	94.88299	100.4087	106.6557	103.4588	96.47843
1	103.28990	113.8003	103.5072	118.8128	120.1028	130.6365

ตารางที่ ข.3 ข้อมูลพื้นที่ใต้กราฟ (Q) ที่ความต่างศั<mark>กย์ใ</mark>ด ๆ




รูปที่ ข.3 พื้นที่ใต้กราฟ (Q) ที่ความต่างศักย์ใด ๆ ก) ครั้งที่ 1 ข) ครั้งที่ 2 ค) ครั้งที่ 3 ข.4 ผลการศึกษาการทดสอบทางสถิติของการเคลื่อนย้ายตำแหน่งอุปกรณ์ในการวัดซีโอดี

จากการทดสอบโดยการวัดและคำนวณพื้นที่ใต้กราฟ (Q) ของสารละลายอิเล็กโทรไลต์โซเดียม ซัลเฟต 0.1 โมลาร์ ภายใต้แสงยูวีความยาวคลื่น 365 นาโนเมตร และจ่ายความต่างศักย์ 0.2 โวลต์ ไป ยังตัวเร่งปฏิริยาซิงค์ออกไซด์ที่ผ่านการสปัตเตอริงเป็นเวลา 120 นาที ขนาด 1x1 ตารางเซนติเมตร โดย ที่ทำการเพิ่มปริมาตรน้ำตัวอย่างครั้งละ 0.5 มิลลิลิตร ในการวัดแต่ละรอบ ๆ ละ 3 นาที โดยที่ไม่มีการ เคลื่อนย้ายตำแหน่งอุปกรณ์ในการวัด พบว่า เมื่อมีการทดลองซ้ำ Q<sub>1</sub> มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.34 คูลอมบ์ และ Q<sub>2</sub> ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.24 คูลอมบ์ และเมื่อทำการทดสอบข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS จาก การตั้งสมติฐานว่า

H<sub>0</sub>; Q<sub>1</sub> = Q<sub>2</sub> และ H<sub>a</sub>; Q<sub>1</sub> ≠ Q<sub>2</sub>

จากข้อมูลตาราง ข.4 นำค่า df ไปหาค่าวิกฤต (Critical:  $t_{cr}$ ) จากตารางการแจกแจง t ที่ lpha 0.05

จะได้ t<sub>cr</sub> = 2.4469

้นำค่า t<sub>cr</sub> เปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการสัง<mark>เกต</mark> (Observed: t<sub>ob</sub>)



รูปที่ ข.4 แสดงค่าวิกฤต

พบว่า t<sub>ob</sub> ตกอยู่ในเขตยอมรับ H<sub>0</sub> จึงสรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ยของ Q ที่ได้จากการใช้ซิงค์ออกไซด์ ทั้งสองแผ่นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

การ ทดสอบ	N	Mean		Std. Deviation			Std. Error Mean		
Q1	7	2.3420		0.07763		0.02934			
Q2	7	2.2386		0.15663		0.05920			
Paired Differences									
Q1 - Q2	Mean	Std. Deviatio	Std. Error	95% C Diffe	l of the rence	t	df	Sig. (2-	
		n	Mean	Lower	Upper			tailed)	
	0.10349	0.18656	0.07051	- <mark>0.0</mark> 6904	0.27602	1.468	6	0.193	

ตารางที่ ข.4 การทดสอบทางสถิติเปรียบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ยของการวัด Q ด้วยซิงค์ออกไซด์ 2 แผ่น



## ข.5 ผลการการทดลองย่อยเมทิลีนบลูด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์

ทำการทดสอบประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส โดยการนำ ้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่สังเคราะห์จากกระบวนการแอโนไดเซชัน 2 สภาวะ ได้แก่ 1) ซิงค์ออกไซด์ที่แอโนโดซ์ โดยจ่ายความต่างศักย์ 3 โวลต์ เป็นเวลา 60 นาที (ZnO-1) และ 2) ซิงค์ออกไซด์ที่ แอโนโดซ์โดยจ่ายความต่างศักย์ 5 โวลต์ เป็นเวลา 30 นาที (ZnO-2 และนำตัวเร่งปฏิกิริยาที่สังเคราะห์ ้จากกระบวนการสปัตเตอริงที่กำลังไฟฟ้า 50 วัตต์ เป็นเวลา 120 นาที (ZnO-3) ไปย่อยเมทิลีนบลูความ เข้มข้นเริ่มต้น 20 ไมโครโมลาร์ ทำการเก็บตัวอย่างไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 664 นาโน เมตร เป็นเวลา 180 นาที ซึ่งก่อนทำการวัดจะต้องทำให้ตัวเร่งปฏิกิริยาเกิดการอิ่มตัวด้วยออกซิเจน เสียก่อน และในการทดลองยังมีชุดควบคุมซึ่งชุดควบคุมนี้เป็นการใช้หลักการโฟโตไลซิส (เติมออกซิเจน ้และฉายแสง) เท่านั้น พบว่า ตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ทั้งสองสภาวะ คือ จ่ายความต่างศักย์ 3 โวลต์ ้เป็นเวลา 60 นาที และจ่ายความต่างศักย์ 5 โวลต์ <mark>เป็น</mark>เวลา 30 นาที มีประสิทธิภาพการย่อยเมทิลีนบลู ้อยู่ที่ 32.4% และ 37.2% ตามลำดับ นอกจากนั้นจากรูปที่ ข.5 จะเห็นได้ว่าตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออก ้ไซด์ที่สังเคราะห์จากกระบวนการแอโนไดเซชันม<mark>ีปร</mark>ะสิ<mark>ท</mark>ธิภาพการย่อยเมทิลีนบลูน้อยกว่าชุดควบคุมซึ่ง ้มีประสิทธิภาพการย่อยเมทิลีนบลู 61.6% จึงสันนิฐานว่าเกิดการหลุดลอกของออกไซด์บนวัสดุตั้งต้น ของตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ ทำให้ตัวอย่าง<mark>ห</mark>ลังการ<mark>ท</mark>ดลองมีสารแขวนลอยและเกิดการบดบังแสง ้ส่วนตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะ<mark>ห์จา</mark>กกระบว<mark>นกา</mark>รสปัตเตอริง มีประสิทธิภาพการย่อยเมทิลี นบลู 66.8% ซึ่งมากกว่าชุดควบคุม





รูปที่ ข.5 เปรียบเทีย<mark>บการ</mark>ย่อยเมทิลีนบลูด้ว<mark>ยกร</mark>ะบวนการโฟโตไลซิส และกระบ<mark>ว</mark>นการโฟโตคะตะไลซิสที่ใช้ตัว<mark>เ</mark>ร่งปฏิริยาแตกต่างกัน



ภาคผนวก ค

การปรับวัตถุประสงค์และขอบเขตงานวิจัย



อ้างถึงผลการพิจารณาการปรับวัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัยและขยายเวลาโครงการวิจัย ตามบันทึกข้อความมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามหนังสือเลขที่ ศธ5614(15)/384 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 นั้น คณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 มีมติ ให้ปรับขอบเขตการวิจัยและขยายเวลาโครงการตามที่ได้เสนอมา โดยคณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อสังเกต ว่า ควรมีการบันทึกไว้ในท้ายเล่มรายงานการวิจัยว่า วัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัยเดิมคืออะไร ดำเนินการแล้วประสบปัญหาอย่างไร ทำให้ต้องมีการปรับวัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัยใหม่เพื่อ เป็นข้อมูลให้กับผู้อ่านรายงานการวิจัย

้โดยมีเหตุผลในการขอปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัย ดังนี้

เนื่องด้วยผม อาจารย์.ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์ ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง "การวิเคราะห์ซีโอดีด้วยวิธีการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสโดยใช้ วัสดุกึ่งตัวนำเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา" รหัสโครงการ SUT7-715-56-24-48 ซึ่งมีกำหนดระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 ซึ่ง ณ บัดนี้ ได้เกินระยะเวลาทุนมาแล้ว อีกทั้งในการศึกษายังไม่บรรลุผลสำเร็จตามที่ตั้งไว้ เนื่องจากมีอุปสรรคในระหว่างการศึกษาวิจัย คือ

1. ในช่วงที่ทำการวัดค่าซีโอดี ค่าที่วัดได้จากเครื่องมือวัดที่สร้างขึ้นเองยังไม่มีความ น่าเชื่อถือ เนื่องจากผลการวัดน้ำตัวอย่างและผลการวัด blank ยังได้ผลที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งยังไม่ทราบ สาเหตุ แต่จากการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหลาย ๆ ท่าน นำไปสู่ข้อสันนิษฐานว่า อาจเป็นเพราะการทำจุด สัมผัสไม่ดีพอ ดังนั้นจึงจะทำการทดสอบต่อไป แต่อย่างไรก็ตามขณะทำการทดสอบเซลล์ไฟฟ้าเคมี (เซลล์ไฟฟ้าเคมีทำด้วยวัสดุซิลิโคน) ที่สร้างขึ้นมาเพื่อทำการวัดค่าซีโอดีเกิดการชำรุดฉีกขาด เนื่องจาก ใช้อิเล็กโทรดอ้างอิงมีการถอดเข้าออกทุกครั้งที่ทำการวัดค่า และอิเล็กโทรดอ้างอิงเกิดการหักซึ่งต้องทำ การสั่งซื้อจากต่างประเทศ จึงเป็นเหตุผลในการขอขยายระยะเวลาการวิจัยครั้งแรกไปแล้วนั้น

2. ในส่วนของวิธีดำเนินงานวิจัยนั้นได้ทำตามแผนการทดลองจนถึงขั้นการตรวจสอบความ ถูกต้องแม่นยำและความเสถียรของวิธีการหาค่าซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส ผลการ ทดสอบส่วนนี้พบว่า เมื่อทำการวิเคราะห์ช้ำของค่าซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส ที่สารละลายความเข้มข้นต่าง ๆ พบว่า ค่าที่ได้จากแต่ละซ้ำนั้น มีค่าไม่ใกล้เคียงกัน และได้ทำการ ทดลองวัดซ้ำในสารละลายความเข้มข้นเดียวกันและใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาตัวเดิมทำซ้ำหลาย ๆ ครั้ง พบว่า ค่าที่ได้จากแต่ละซ้ำมีค่าไม่ใกล้เคียงกัน ซึ่งหมายความว่าค่าซีโอดีที่ได้จากวิธีนี้ยังไม่สามารถเชื่อถือได้ ซึ่ง ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานหลาย ๆ สมมติฐานและได้ปรับเปลี่ยนวิธีการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา วิธีการวัดค่า เพื่อตอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทำการทดสอบและทำการวิเคราะห์หลายการทดลองมาก และพบว่าการวัด ค่าซีโอดีด้วยวิธีนี้ยังไม่สามารถเชื่อถือได้ ส่งผลให้ไม่สามารถที่จะทำการทดลองศึกษาหาปัจจัย (ค่าพีเอช ค่าคลอไรด์ ค่าแอมโมเนียม) ที่มีผลต่อการวิเคราะห์หาค่าซีโอดีด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส รวมทั้งไม่สามารถทำการทดลองสุดท้ายเกี่ยวกับการทดสอบวัดค่าซีโอดีจากน้ำเสียจริงจากแหล่งต่าง ๆ ต่อไปได้

จากเหตุผลอุปสรรคในการวิจัยและแผนการวิจัยที่จะทำต่อไปข้างต้น ผู้วิจัยจึงเรียนมาเพื่อขอ หารือในการปรับวัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัย โดยขอปรับเพื่อให้สามารถปิดทุนวิจัยนี้ได้และขอ ขยายระยะเวลาการวิจัยออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3 เดือนคือตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560 ซึ่งได้รับการพิจารณาการปรับวัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัยและขยายเวลาโครงการ ตามหนังสือเลขที่ ศธ5614(15)/384 ดังเอกสารแนบท้าย รายละเอียดข้อมูลการปรับ ดังนี้

## วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย (เดิม)

 เพื่อประยุกต์ใช้กระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสในการวิเคราะห์หา ค่าซีโอดีในน้ำเสีย

 เพื่อศึกษาถึงความถูกต้องและแม่นยาของการใช้วัสดุกึ่งตัวนาชนิดต่างๆ ใน การวิเคราะห์ค่าซีโอดีในน้ำเสียโดยใช้กระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส

## วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย (ใหม่)

1. เพื่อศึกษาการใช้กระบ<mark>วน</mark>การโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสในการวิเคราะห์ หาค่าซีโอดีในน้ำเสีย

2. เพื่อศึกษาถึงความถูก<mark>ต้องและ</mark>แม่นยำของการใช้วัสดุกึ่งตัวนำชนิดต่าง ๆ ใน การวิเคราะห์ค่าซีโอดีในน้ำเสียโดยใช้กระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส

## ขอบเขตของโครงการวิจัย (เดิม)

งานวิจัยนี้เน้นศึกษาการหาค่าซีโอดี ด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส โดยใช้วัสดุกึ่ง ตัวนำ TiO<sub>2</sub> ที่สังเคราะห์ขึ้นจากกระบวนการแอโนไดเซชัน ซึ่งในการตรวจสอบความถูกต้องและ ความแม่นยำของกระบวนการนี้ จะศึกษาเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์หาค่าซีโอดีด้วยวิธีมาตรฐานได โครเมต (K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>) และใช้ทดลองกับสารอินทรีย์ที่ให้ค่าซีโอดีในเชิงทฤษฎี ทำการศึกษาเกี่ยวกับตัว รบกวนการวิเคราะห์ค่าซีโอดี ทดลองวิเคราะห์ค่าซีโอดีของน้ำเสียจริงจากแหล่งต่าง ๆ รวมทั้งศึกษา ตัวเร่งปฏิกิริยาอื่น ๆ ในการวิเคราะห์ซีโอดีโดยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสด้วย

## ขอบเขตของโครงการวิจั<mark>ย (ให</mark>ม่)

งานวิจัยนี้เน้นศึกษาการหา<mark>ค่าซีโอดี ด้วยกระบวนการโฟโต</mark>อิเล็กโตรคะตะไลซิส โดยใช้วัสดุกึ่ง ตัวนำ TiO<sub>2</sub> และวัสดุกึ่งตัวนำ ZnO ซึ่งในการตรวจสอบความถูกต้องและความแม่นยำของกระบวนการ นี้ จะศึกษาเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์หาค่าซีโอดีด้วยวิธีมาตรฐานไดโครเมต (K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>) และใช้ ทดลองกับสารอินทรีย์ที่ให้ค่าซีโอดีในเชิงทฤษฎี

SUT7-71	5-56-	24-48
---------	-------	-------

1960

ศากรรม**ศาสตร์** 

.2560..



# บันทึกข้อความ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน่วยงาน ฝ่ายประสานงานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 4753 โทรสาร 475

ที่ ศธ 5621/1618

**วันที่ 2**5 สิงหาคม 2560

สำนักวิชา

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการปรับวัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย และขยายเวลาโครจัการวิจัย สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

เรียน คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ผ่านหัวหน้าสถานวิจัย)

ตามหนังสือที่ ศธ 5614(15)/384 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ซึ่ง อาจารย<u>์ คริสิสิภิชน วัชเร็บไท้ร้างค</u>ั สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้ส่งเรื่องปรับวัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย และขยายเวลาโครงการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ซีโอดีด้วยวิธีการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสโดยใช้วัสดุกึ่งตัวนำเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา มาเพื่อขอความ เห็นซอบจากคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแล<mark>ะจัดสร</mark>รงบประมาณโครงการวิจัย นั้น

คณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 **มีมติให้ปรับวัตถุประสงค์** ขอบเขตการวิจัย และขยายเวลาโครงการวิจัยได้ตามที่เสนอมา โดยคณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อสังเกตว่า ควรมี การบันทึกไว้ในท้ายเล่มรายงานการวิจัยว่า วัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัยเดิมคืออะไร ดำเนินการแล้วประสบ ปัญหาอย่างไร ทำให้ต้องมีการปรับวัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัยใหม่เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้อ่านรายงานการ วิจัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งหัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

สำเนาเรียน ฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สบวพ.

เรียน ล.ค. อโรน อัสเนอหรืององ เมื่อโปรจุกราย แอกรณีกรณ 23 Jonwitte

รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพรษ์ อุทารสกุล หัวหน้าสถานวิรัย สำนักวิธาริสรกรรมศาสตร์ ปฏิบัติการแทนคณบดี

# ประวัตินักวิจัย

## อาจารย์ ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์

การศึกษา/คุณวุฒิ :	ปริญญาเอก :Ph.D. (Environmental management) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท :	วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโมโลยีพระ ออบเกล้ารบบรี
ปริญญาตรี :	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่งปัจจุบัน :	หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกร <mark>รมสิ่</mark> งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน	
เม.ย. 46 – ส.ค. 47	Research assistance of Assoc. Prof. Dr. Puangrat Kajitvichyanukul, King Mongkut's University of Technology Thonburi,
	Bangkok,Thaila <mark>nd banka banka</mark>
ก.พ. 49 - ส.ค. 50	Research Assistance, Center for Renewable Energy Science and
	Technology (CREST), Department of Chemistry & Biochemistry,
	The University of Texas at Arlington, Arlington, Texas, USA.
มี.ค. 51 - ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

### ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย : AWARDS

 Distinguished Research Award, Nanotechnology and Nanomaterial Safety Management, Thailand Research Fund (TRF), Thailand, 2014

### A CHAPTER IN BOOK

 Puangrat Kajitvichyanukul, Jirapat Ananpattarachai, Apichon Watcharenwong, "Green Products: Production", Encyclopedia of Environmental Management, Taylor and Francis: New York, Published online: 01 May 2013; 1253-1261.

### INTERNATIONAL JOURNAL PUBLICATIONS

• Watcharenwong, A., Noguchi, S., Kawai, T., Ogata, T., Unuma, H., "Self-organized TiO<sub>2</sub> nanotubes and their photocatalytic performance measured using spin-trap ESR spectroscopy", Romanian Review Precision Mechanics, Optics and Mechatronics, Issue 43, 2013, Pages 91-97

- A. Watcharenwong, W. Chanmanee, N. R. de Tacconi, C. R. Chenthamarakshan, P. Kajitvichyanukul, and K. Rajeshwar, "Anodic growth of nanoporous WO<sub>3</sub> films: morphology, photoelectrochemical response and photocatalytic activity for methylene blue and hexavalent chrome conversion", *Journal of Electroanalytical Chemistry*, Vol. 612, pp. 112-120, 2008
- W. Chanmanee, A. Watcharenwong, C. R. Chenthamarakshan, P. Kajitvichyanukul, N. R. de Tacconi, K. Rajeshwar, "Formation and Characterization of Self-Organized TiO<sub>2</sub> Nanotube Arrays by Pulse Anodization" *Journal of American Chemical Society*, Vol. 130, pp. 965-974, 2008 (*impact factor = 9.907*)
- A. Watcharenwong, W. Chanmanee, N. R. de Tacconi, C. R. Chenthamarakshan, P. Kajitvichyanukul, and K. Rajeshwar, "Self-organized TiO<sub>2</sub> nanotube arrays by anodization of Ti substrate: Effect of anodization time, voltage and medium composition on oxide morphology and photoelectrochemical response", *Journal of Materials Research*, Vol. 22, pp. 3186-3195, 2007
- W. Chanmanee, A. Watcharenwong, C. R. Chenthamarakshan, P. Kajitvichyanukul, N. R. de Tacconi, K. Rajeshwar, "Titania nanotubes from pulse anodization of titanium foils", *Electrochemistry Communications*, Vol. 9, pp. 2145–2149, 2007 (*impact factor = 3.388*)
- N. R. de Tacconi, C. R. Chenthamarakshan, G. Yogeeswaran, A. Watcharenwong, R. S. de Zoysa, N. A. Basit and K. Rajeshwar, "Nanoporous TiO<sub>2</sub> and WO<sub>3</sub> Films by Anodization of Titanium and Tungsten Substrates: Influence of Process Variables on Morphology and Photoelectrochemical Response", *Journal of Physical Chemistry B*, Vol. 110, pp. 25347-25355, 2006

#### **BOOK SERIES**

- Apichon Watcharenwong, Yotsapon Bailuang, and Puangrat Kajitvichyanukul, "Synthesis and Characterization of Monodisperse Magnetite Nanoparticles by Hydrothermal Method", *Key Engineering Materials*, Vol. 737, pp 367-372, 2017
- Apichon Watcharenwong, Ariya Jindanant, and Puangrat Kajitvichyanukul, "Characterization of Pulse Anodized Titanium Dioxide Nanotubes", *Key Engineering Materials,* Vol. 737, pp 373-378, 2017
- Apichon Watcharenwong, Narudon Saijaioup, Yotsapon Bailuang, and Puangrat Kajitvichyanukul, "Morphology and Wettability of Nanoporous Aluminium Oxide Film Prepared by Anodization", *Key Engineering Materials,* Vol. 737, pp 174-178, 2017

#### RIGINAL AND NATIONAL JOURNAL PUBLICATIONS

- Apichon Watcharenwong, Yotsapon Bailuang, Akira Rittirat, Patchapong Thamavate, and Supasan Chumjun, "Comparing the possibility of using cationic starch for removal of suspended paricles and algae", Thai environmental engineering journal, Vol. 31 No. 1, 2017
- P. Kajitvichyanukul, A. Vatcharenwong, "Role of pH, Organic and Inorganic Anions on Photocatalytic Reduction Of Chromium(VI) using TiO<sub>2</sub> and Ultraviolet Light", Asean Journal of Science and Technology for Development, Vol. 22, No. 1&2, pp. 169-179, 2005
- P. Kajitvichyanukul, K. Daramueng, A. Vatcharenwong, "Acid and Alkali Extraction of Trivalent Chromium from Titanium Dioxide Surface" Songkhlanakarin Journal of Science and Technology, Vol. 27, No. 2, pp. 47-53, 2005
- P. Kajitvichyanukul, P. Amornchat, A. Vatcharenwong, J. Ananpattarachai, "Structure and Photocatalytic characteristics of TiO<sub>2</sub> Thin Film coated on Stainless Steel for Chromium(VI) Removal Application, *Chiang Mai University Journal*, Vol. 3, pp.79-86, 2005
- P. Kajitvichyanukul, S. Pongpom, A. Vatcharenwong, J. Ananpattarachai, "Effects of Acetyl Acetone on Property of TiO<sub>2</sub> Thin Film for Photocatalytic Reduction of Chromium (VI) from Aqueous Solution, *Chiang Mai University Journal*, Vol. 3, pp. 87-93, 2005
- P. Kajitvichyanukul, A. Vatcharenwong, "Contradiction Effect of pH on the Photocatalytic Reduction of Chromium (VI) and Thallium (I)". Asean Journal of Science and Technology for Development, Vol. 21, No.4, pp. 269-280, 2004
- P. Kajitvichyanukul, **A. Vatcharenwong**, "Adsorption Behavior of Chromium (VI) on Titanium Dioxide Surface" *Thai Environmental Engineering Journal*, Vol. 18, No. 1, pp. 87-95, 2004

#### REFEREED CONFERENCE PROCEEDINGS

- Apichon Watcharenwong, Ariya Jindanant, and Puangrat Kajitvichyanukul, "Characterization of Pulse Anodized Titanium Dioxide Nanotubes" Proceeding of the International Conference on Material Science and Engineering Technology, Phuket, Thailand, 14-16 October, 2016
- Apichon Watcharenwong, Yotsapon Bailuang, and Puangrat Kajitvichyanukul, "Synthesis and Characterization of Monodisperse Magnetite Nanoparticles by Hydrothermal Method" Proceeding of the International Conference on Material Science and Engineering Technology, Phuket, Thailand, 14-16 October, 2016

- Apichon Watcharenwong, Narudon Saijaioup, Yotsapon Bailuang, and Puangrat Kajitvichyanukul, "Morphology and Wettability of Aluminium Oxide Film Prepared by Anodization" Proceeding of the International Conference on Material Science and Engineering Technology, Phuket, Thailand, 14-16 October, 2016
- Apichon Watcharenwong, Yotsapon Bailuang, Akira Rittirat, Patchapong Thamavate, and Supasan Chumjun, "Comparing the possibility of using cationic starch for removal of suspended particles and algae" Proceedings of the 15<sup>th</sup> National Environmental Conference, by Environmental Engineering Association of Thailand, Bangkok, Thailand, 11-13 May, 2016
- Apichon Watcharenwong, Pimchanok Leuasoongnoen, "Synthesis of rhombic ZnO rods using anodization technique and their properties", GTSNN 2014 International Conference on "Safe and Sustainable Nanotechnology" (in conjunction with 4th German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology), Phitsanulok, Thailand, October 14<sup>th</sup>-17<sup>th</sup>, 2014
- Apichon Watcharenwong, Shun Noguchi, Takahiro Kawai, Tateaki Ogata, and Hidero Unuma, "Self-Organized TiO<sub>2</sub> Nanotubes and Their Photocatalytic Performance Measured Using Spin-Trap ESR Spectroscopy", Proceeding of 5<sup>th</sup> International Conference on Innovations, Recent Trends and Challenges in Mechatronics, Mechanical Engineering and New High-Tech Products Development, MECAHITECH'13, Bucharest, Romania, September 12<sup>th</sup>-13<sup>th</sup>, 2013
- N. Bussabong, A. Watcharenwong, and S. Dararat, "Biogas Production from Ruzi grass in the Continuous Stirred Tank Reactor (CSTR)", Proceedings of 2<sup>nd</sup> International Conference on Agriculture and Environment Systems (ICAES'13), Pattaya (Thailand), April 23-24, 2013
- Sarunya Tong-un and Apichon Watcharenwong "Preparation of TiO<sub>2</sub> Nanotubes as Photocatalyst for Carbon Monoxide Removal" Proceedings of International conference on Nanothailand 2012: Nanotechnology for the benefits of mankind, Khon Kaen, Thailand, April 9-11, 2012
- Arnanpapha Chuensab and Apichon Watcharenwong "Photocatalytic Performance of Nanoporous WO<sub>3</sub> for Carbon Monoxide Removal" Proceedings of International Conference on Chemical, Environmental and Biological Sciences (ICCEBS'2012) Penang, Malaysia, February 11-12, 2012
- Arnanpapha Chuensab and Apichon Watcharenwong "Treatment of CO in Photocatalysis process using WO<sub>3</sub>" Proceedings of the 10<sup>th</sup> National

Environmental Conference, by Environmental Engineering Association of Thailand, Songkhla, Thailand, March, 2011

- Sarunya Tong-un and Apichon Watcharenwong "Titanium Dioxide Nanotubes with Treatment of Carbon monoxide" Proceedings of the 10<sup>th</sup> National Environmental Conference, by Environmental Engineering Association of Thailand, Songkhla, Thailand, March, 2011
- Apichon Watcharenwong , Wilaiwan Chanmanee , Norma R. de Tacconi, C. Ramannair Chenthamarakshan , Puangrat Kajitvichyanukul, Krishnan Rajeshwar, "Effect of pulsing voltage and electrolyte composition on photoelectrochemical response of composite TiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub> nanotubes obtained from pulse anodization using Ti foil", Proceedings of the 1<sup>st</sup> international conference on NanoThailand Symposium 2008 (NTS 2008) November 6 8, 2008, Bangkok, Thailand, 2008
- Watcharenwong Apichon, Chanmanee Wilaiwan, Kajitvitchyanukul Puangrat, Chenthamarakshan C. R., de Tacconi N. R., Rajeshwar Krishnan, "Anodic Growth of Nanoporous TiO<sub>2</sub> and WO<sub>3</sub> films: Influence of Process Variables on Morphology, Photoelectrochemical response and Photocatalysis applications", Proceedings of the 2<sup>nd</sup> international conference on Advances in Petrochemicals and Polymers (ICAPP 2007) June 25 – 28, 2007, Bangkok, Thailand, 2007
- Krishnan Rajeshwar, Wilaiwan Chanmanee, Apichon Watcharenwong, C.
  Ramannair

Chenthamarakshan, Puangrat Kajitvichyanukul, and Norma R. de Tacconi, "Titania Nanotubes from Pulse Anodization of Titanium foils", Proceedings of the Twenty-Ninth DOE Solar Photochemistry Research Conference, Airlie Conference Center Warrenton, Virginia, USA, June 10-13, 2007

- P. Kajitvichyanukul, K. Daramueng, A. Vatcharenwong "Acid and Alkali Extraction of Trivalent Chromium from Titanium Dioxide Surface", Proceedings of the <sup>3rd</sup> National Environmental Conference, by Environmental Engineering Association of Thailand, Songkhla, Thailand, January 28-30, 2004
- P. Kajitvichyanukul, A. Vatcharenwong, "Role of pH, organic and inorganic ions on the photocatalytic reduction of Chromium (VI) using TiO<sub>2</sub> and ultraviolet light", Proceedings of ASIAN WATERQUAL2003, IWA Asia-Pacific conference, Thailand, 2003
- P. Kajitvichyanukul, A. Vatcharenwong, "Effect Of pH On Dark Adsorption And Photocatalysis Of Chromium(VI) And Thallium(I) In Aqueous Titanium Dioxide Suspension", Proceedings of An International Conference on Advances in Petrochemicals and Polymers in the New Millennium, Thailand, July 22-25, 2003

 P. Kajitvichyanukul, A. Vatcharenwong, "A Study of Adsorption Behavior of Chromium(VI) on Titanium Dioxide Surface", Proceedings of the 2<sup>nd</sup> National Environmental Conference, by Environmental Engineering Association of Thailand, Khon Kaen, Thailand, January, 2003

